



2012 年度知的財産活動実態調査

The Survey on Intellectual Property-Related

Activities in Korea 2012

特許庁・貿易委員会

この報告書は「特許庁」と「貿易委員会」の主管の下で、
「韓国知識財産研究院」が調査を実施し、その結果を収録
したものです。

提出文

特許庁長、貿易委員会委員長 御中

本報告書を「2012年度知的財産活動実態調査」課題の最終報告書として提出致します。

2012.12.

総括責任者：カン・キョンナム(韓国知識財産研究院 副研究委員)
細部責任者： ビョン・ヘヨン(韓国知識財産研究院 前任研究員)
参加研究員： キム・ボムテ(韓国知識財産研究院 副研究委員)
 チェ・ソヒ(韓国知識財産研究院 委嘱研究員)
 ファン・ボウン(韓国知識財産研究院 委嘱研究員)

アンケート調査機関名：コリアデータネットワーク(KDN)

利用者のために

1. この報告書は韓国における企業及び大学・公共研究機関の知的財産活動の現状を把握するため、基準年度に産業財産権の出願及び登録の実績のある企業及び大学・公共研究機関を対象に 2012 年に実施した知的財産活動調査の結果を収録したものである。
2. この報告書に収録されている統計数値は標本調査の結果を基に母数推定(parameter estimates)したものである。
3. 統計表の統計数値は全て四捨五入上の差異によって各項目の合計と総計が一致しない可能性があり、複数回答項目は構成比の合計が 100 を超過する。
4. 産業分類は 2007 年 12 月 28 日改正告示された第 9 次標準産業分類を適用している。それに従って 2007 年度知的財産活動調査結果と比べる時は業種分類の差異を認知した上で使用しなければならない。
5. この報告書で使用されている図と表の年度は別途表示が無い限り全て 2012 年度の調査結果を意味する。
6. 2011 年度に知的財産活動実態調査が知的財産権侵害実態調査と統合されたことで母集団の基準及び母数推定方式が変更され、知的財産活動実態調査結果の時系列上の比較のためには、既存(2010 年以前)方法による母数値の推定値を使用しなければならない。
7. この報告書の内容に関する問合せは韓国知識財産研究院 IP 政策研究チーム(02-2189-2628/2629)が担当している。また、報告書の内容は韓国特許庁のホームページ

(<http://www.kipo.go.kr>)または貿易委員会のホームページ(<http://www.ktc.go.kr>)でも確認することができる。

<目次>

要約文	17
第1章 調査の概要	31
第1節 調査の目的及び沿革.....	31
1.調査の目的	31
2.調査沿革	31
第2節 調査質問事項及び標本の設計	33
1.調査質問事項の設計.....	33
2.標本設計	36
第3節 調査方法及び回答率.....	43
1.調査方法	43
2.調査結果	46
第2章 企業の知的財産活動.....	49
第1節 知的財産活動のインフラ	49
1.知的財産担当組織及び人材	49
2.知的財産担当人材に対する職務教育及び人件費・教育費	54
3.知的財産サービスの活用状況	57

第2節	知的財産の創出	61
1.	研究開発過程における特許情報の活用	61
2.	外部から導入した知的財産の実績及び今後の計画	67
3.	職務発明補償	72
4.	効果的な知的財産創出のために必要な政策支援	74
第3節	知的財産の保護	76
1.	予備評価の実施状況及び方法	76
2.	研究開発成果の保護戦略	78
3.	産業財産権の海外出願/登録及び国内出願計画	81
4.	産業財産権の出願/審査/維持費用及び関連規定の状況	84
5.	効果的な知的財産保護のために必要な政策支援	87
第4節	知的財産の活用	89
1.	知的財産実査	89
2.	知的財産の活用戦略	91
3.	知的財産権の売却/移転及び活用状況	95
4.	知的財産を効果的に活用するために必要な政策支援	99
第5節	知的財産の侵害及び紛争	101
1.	知的財産権の侵害及び被害規模	101
2.	知的財産権侵害に対する事後対応	118
3.	知的財産権紛争に関する難点及び必要な政策支援	126

第3章 大学及び公共研究機関の知的財産活動..... 129

第1節 知的財産活動インフラ..... 129

1.知的財産担当組織及び人材..... 129

2.知的財産担当人材に対する職務教育及び人件費・教育費..... 133

3.知的財産サービスの活用及び総合的な管理システムの構築状況 136

第2節 知的財産の創出..... 140

1.研究開発過程における特許情報の活用..... 140

2.知的財産を創出するための活動戦略..... 145

3.職務発明補償..... 147

4.効果的な知的財産創出のために必要な政策支援..... 150

第3節 知的財産の保護..... 152

1.予備評価実施状況及び方法..... 152

2.研究開発成果の保護戦略..... 154

3.産業財産権の海外出願・登録及び国内出願計画..... 157

4.産業財産権の出願・審査・維持費用及び関連規定の状況..... 159

5.効果的な知的財産保護のために必要な政策支援..... 160

第4節 知的財産の活用..... 162

1.知的財産実査..... 162

2.知的財産の活用戦略..... 164

3.知的財産権の売却・移転及び活用状況..... 167

4.効果的な知的財産活用のために必要な政策支援.....	169
第5節 知的財産の侵害及び紛争.....	170
1.知的財産権の侵害及び事後対応.....	170
2.知的財産権紛争関連の難点及び必要な政策支援.....	171
第4章 2012年韓国知的財産活動の診断.....	173
1.知的財産先行活動の変化.....	173
2.外部からの知的財産導入の減少.....	177
3.知的財産保護戦略としての出願比率の増加.....	179
4.知的財産移転に向けた努力及び成果の減少.....	182
5.知的財産の活用及び事業化比率の増加.....	185
6.知的財産担当組織保有比率の改善.....	187
7.知的財産権侵害類型の特徴.....	190
用語整理.....	192
<付録1>業種分類と韓国標準産業分類表(KSIC)との連結	195
<付録2>調査票：企業用及び大学・公共(研)用.....	197

<表目次>

[表 1.1]知的財産活動の分類.....	33
[表 1.2]知的財産活動実態調査の主要調査項目.....	34
[表 1.3]既存知的財産権侵害実態調査と母集団の比較.....	36
[表 1.4]年度別母集団の規模.....	38
[表 1.5]企業母集団の分布.....	38
[表 1.6]大学・公共研究機関母集団の分布.....	39
[表 1.7]企業登録件数別の全数調査対象の比率.....	40
[表 1.8]企業標本の分布.....	40
[表 1.9]2段階アンケート調査のプロセス及び方法.....	43
[表 1.10]調査拒否及びアバウトな回答である時の対応策.....	44
[表 1.11]回答が無い場合の対応策及び欠測値の補正方法.....	45
[表 1.12]有効標本の規模及び回答率.....	46
[表 1.13]業種別有効標本の規模及び回答率.....	46
[表 1.14]業種別、企業類型別回答企業の分布.....	47
[表 1.15]大学・公共(研)類型別回答機関の分布.....	48
[表 2.1]職務教育の実施を希望する場合に扱うべき内容.....	55
[表 2.2]知的財産担当者の人件費及び教育費の状況.....	57
[表 2.3]知的財産サービスの利用状況.....	58
[表 2.4]最近3年間外部から知的財産を導入した企業の比率.....	70
[表 2.5]職務発明補償類型別の実施比率.....	73
[表 2.6]効果的な知的財産創出のための政策支援の必要性.....	75
[表 2.7]研究開発成果保護戦略の活用度.....	79
[表 2.8]2012年対比2013年の知的財産権出願計画.....	82
[表 2.9]産業財産権の国内出願の増減に影響を及ぼす要因.....	83
[表 2.10]知的財産の出願・審査・維持費用.....	84
[表 2.11]効果的な知的財産保護のための政策支援の必要性.....	87
[表 2.12]国内技術取引システムの活用度.....	93
[表 2.13]回答企業が保有している特許の活用率及び事業化率.....	99

[表 2.14]効果的な知的財産活用のための政策支援の必要性	99
[表 2.15]出願規模別の特許侵害比率	103
[表 2.16]出願規模別の商標権侵害比率	104
[表 2.17]産業財産権出願規模別の損害賠償金または被害金額発生企業の比率.....	114
[表 2.18]産業財産権の出願規模別に実現された金額発生企業の比率.....	115
[表 2.19]産業財産権出願規模別の未実現被害金額が発生した企業の比率.....	116
[表 2.20]全体侵害被害規模の推定	117
[表 2.21]知的財産権侵害に対応するために必要な政府政策	128
[表 3.1]職務教育の実施を希望する場合、取り扱うべき内容	134
[表 3.2]知的財産担当者の人件費及び教育費の状況	135
[表 3.3]知的財産サービスの利用状況	136
[表 3.4]職務発明補償の類型別実施比率	150
[表 3.5]効果的な知的財産創出のための政策支援の必要性	151
[表 3.6]2012年対比 2013年知的財産権の出願計画	158
[表 3.7]産業財産権の国内出願の増減に影響を及ぼす要因	158
[表 3.8]知的財産の出願・審査・維持費用	159
[表 3.9]効果的な知的財産保護のための政策支援の必要性	160
[表 3.10]国内技術取引システムの活用度	166
[表 3.11]効果的な知的財産活用のための政策支援の必要性	169
[表 3.12]知的財産権侵害への対応における難点.....	171
[表 3.13]知的財産権侵害に対応するために必要な政策支援	172

○図目次

[図 2.1]知的財産担当組織の保有状況	49
[図 2.2]知的財産担当組織総括者の地位	50
[図 2.3]知的財産担当人材の保有状況	51
[図 2.4]知的財産関連業務を行っている企業比重	52
[図 2.5]知的財産専門担当人材の採用予定比率	53
[図 2.6]知的財産権担当人材に対する職務教育の状況及び必要性	55
[図 2.7]知的財産人材の能力を高めるために必要な政府政策	56
[図 2.8]知的財産サービス提供機関別の利用比重	59
[図 2.9]先行特許情報調査の実施状況	61
[図 2.10]先行特許調査の必要性	62
[図 2.11]出願件数別の先行特許調査必要性	63
[図 2.12]先行特許調査を行う場合の遂行人材	63
[図 2.13]知的財産基礎統計の活用状況	64
[図 2.14]企業類型別の知的財産情報システムの活用	66
[図 2.15]出願規模別の知的財産情報システムの活用	67
[図 2.16]知的財産の導入を拡大する予定である企業の比率	68
[図 2.17]知的財産導入に向けた投資拡大の方向	69
[図 2.18]国内知的財産導入企業の比率及び平均導入件数	71
[図 2.19]知的財産を導入した企業の類型別導入件数	71
[図 2.20]職務発明補償規定の保有及び活用状況	72
[図 2.21]職務発明補償規定を保有していない場合、その主な理由	73
[図 2.22]産業財産権出願前の社内予備評価の実施状況	76
[図 2.23]予備評価実施の必要性	77
[図 2.24]予備評価を行っている場合の実行人材	78
[図 2.25]研究開発成果保護戦略の活用比率及び活用度	79
[図 2.26]発明件数対比出願比率及び非公式的な権利保護の比率	80
[図 2.27]国内知的財産保護水準に対する意見	81

[図 2.28]産業財産権の海外出願/登録企業の比重	82
[図 2.29]営業秘密の管理及び技術流出防止指針の保有・遵守状況	86
[図 2.30]営業秘密管理及び技術流出のための人材管理状況	86
[図 2.31]営業秘密管理及び技術流出防止のための物的管理状況	87
[図 2.32]知的財産実査の実施状況	89
[図 2.33]知的財産実査の必要性	90
[図 2.34]知的財産実査を行っている場合の実行人材	90
[図 2.35]最近3年間技術取引機関に対する業務依頼及び締結状況	92
[図 2.36]技術取引機関などに業務を依頼した場合の主な費用支給方法	93
[図 2.37]特許技術の事業化における最大の問題	95
[図 2.38]知的財産の売却・移転状況	96
[図 2.40]特許権の活用率及び事業化率	97
[図 2.41]その他産業財産権の事業化率	98
[図 2.42]企業類型別の知的財産権侵害の被害比率	101
[図 2.43]出願件数別の知的財産権侵害の被害比率	102
[図 2.44]産業財産権類型別の侵害被害件数	102
[図 2.45]企業類型別の産業財産権侵害の被害比率	103
[図 2.46]権利類型及び被害状況	105
[図 2.47]出願規模別の産業財産権侵害の比重	105
[図 2.48]産業財産権出願規模別の侵害製品製造者の類型別比率	106
[図 2.49]侵害製品製造者別の被害状況	107
[図 2.50]侵害製品製造地域別の被害状況	108
[図 2.51]産業財産権出願規模別の侵害製品製造地域の比率	109
[図 2.52]侵害製品流通地域別の被害状況	110
[図 2.53]侵害製品の流通類型及び被害状況	111
[図 2.54]侵害製品の発見経路別の被害状況	112
[図 2.55]知的財産権侵害の被害が発生した主な原因	113
[図 2.56]損害賠償額または和解金の規模	113
[図 2.57]実現された被害金額の規模	115
[図 2.58]未実現被害金額の規模	116

[図 2.59]知的財産権侵害に対する対応	118
[図 2.60]企業類型別の国内企業に対する侵害対応方法	119
[図 2.61]企業類型別の海外企業に対する侵害対応方法	119
[図 2.62]侵害製品の流通類型別の対応状況	120
[図 2.63]対応活動を展開しない場合の理由	121
[図 2.64]企業類型別の対応活動(行政機関に知的財産権侵害製品に対する取締り及び侵害事実に対する調査要請)を展開しない理由.....	122
[図 2.65]企業類型別の対応活動(告訴・告発、仮処分、民・刑事訴訟など司法的な救済措置の申請)を展開しない理由	123
[図 2.66]企業類型別の対応活動(侵害企業に警告または合意に向けた努力など独自対応)を展開しない理由	124
[図 2.67]知的財産権侵害対応費用	125
[図 2.68]知的財産権侵害の対応における難点.....	126
[図 2.69]他社知財権侵害による紛争時の対応における難点	127
[図 3.1]知的財産担当組織の状況	129
[図 3.2]知的財産専門担当人材の保有状況	130
[図 3.3]知的財産担当者の主要業務	131
[図 3.4]知的財産担当人材の採用計画	132
[図 3.5]知的財産権担当人材に対する職務教育の現状及び必要性	133
[図 3.6]知的財産人材の能力を高めるために必要な政府政策	135
[図 3.7]知的財産サービス提供機関別の利用比重.....	137
[図 3.8]知的財産管理システムの構築及び活用状況.....	138
[図 3.9]知的財産管理システムの構築費用	139
[図 3.10]先行特許情報調査の現状	140
[図 3.11]先行特許情報調査の必要性	141
[図 3.12]先行特許調査を行う場合の実施人材.....	142
[図 3.13]先行特許調査に対する機関の支援	143
[図 3.14]知的財産基礎統計情報の活用状況	144
[図 3.15]機関類型別知的財産情報システムの活用.....	145
[図 3.16]優れた知的財産を創出するための活動及び戦略.....	146

[図 3.17]職務発明補償制度に対する認識度	148
[図 3.18]職務発明意補償規定の保有及び活用状況	148
[図 3.19]職務発明補償規定を保有していない場合、その主な理由	149
[図 3.20]産業財産権の出願などに先立ち予備評価の実施状況	152
[図 3.21]予備評価実施の必要性	153
[図 3.22]予備評価を実施している場合の実施人材	154
[図 3.23]研究開発成果保護戦略の活用比率及び活用度	155
[図 3.24]発明件数対比出願比率及び非公式的な権利保護の比率	156
[図 3.25]現在国内知的財産保護水準に対する認識	156
[図 3.26]特許権の海外出願/登録機関の比重	157
[図 3.27]知的財産実査の実施状況	162
[図 3.28]知的財産実査の必要性	163
[図 3.29]知的財産実査を行っている場合、その実施人材	163
[図 3.30]最近 30 年間技術取引機関への業務依頼及び締結状況	164
[図 3.31]技術取引機関などに業務を依頼した場合の主な費用支払い方法	165
[図 3.32]知的財産を売却・移転した機関の比率及び件数	167
[図 3.33]特許権の活用率	168
[図 3.34]知的財産権侵害への事後対応	171
[図 4.1]企業の先行活動実施比率の推移	174
[図 4.2]大学及び公共(研)の先行活動実施比率の推移	175
[図 4.3]全体研究開発課題、発明、保有知的財産のうち実施比率の変化	176
[図 4.4]先行活動の必要性に対する認識の変化	177
[図 4.5]知的財産導入の推移	178
[図 4.6]知的財産導入の拡大方向の変化	179
[図 4.7]発明件数対比出願率の推移	180
[図 4.8]国内知的財産保護水準の強化が必要	181
[図 4.9]海外出願及び登録の推移	182
[図 4.10]最近 3 年間技術取引、技術マーケティングのための業務依頼の推移	183
[図 4.11]国内技術取引システム活用比率の推移	184

[図 4.12]国内技術取引システム活用度の推移.....	184
[図 4.13]知的財産の売却・移転の推移.....	185
[図 4.14]特許活用率及び事業化率の平均.....	186
[図 4.15]全体特許活用率及び事業化率.....	187
[図 4.16]知的財産担当組織保有比率の推移.....	188
[図 4.17]専門担当人材の保有比率及び専門担当人材数の推移.....	189
[図 4.18]知的財産担当人材職務教育の実施状況.....	190

要約文

I. 調査目的及び調査概要

1. 必要性及び目的

- 知的財産政策を効率的に樹立・推進するため、各企業、大学・公共研究機関の活動状況を総合的に把握及び分析できる統計資料が必要
- 知識財産基本法第31条に基づき、知的財産の創出・保護・活用と侵害などの状況について「知的財産活動実態調査」を実施

2. 統計作成の沿革

- 2006年：企業を対象に知的財産活動調査を実施
 - 法的根拠：統計法による政府承認統計(第13802号、「知的財産活動調査」)
- 2007年：調査対象を大学・公共(研)まで拡大
 - 名称の変更：知的財産活動実態調査(The Survey of Intellectual Property-Related Activities)
 - 知的財産活動の段階別先行活動に対する質問事項などを細分化
- ～2010年：ニーズによって調査項目を修正するなど改善活動を展開
- 2011年：調査領域の拡大及び法的根拠の確保
 - 知識財産基本法による法的根拠の確保
 - 被害・侵害状況に対する調査領域の拡大
 - 貿易委員会の「知的財産権侵害実態調査」と統合

□2012年：知的財産の範囲及びニーズによって調査項目を修正するなど改善活動を展開

3.調査概要

□調査期間：2012.8.20～2012.11.23(約3ヶ月)

□調査標本の設計

○2012年を基準に、基準年度(出願2009年と2010年、登録2007年～2011年)に産業財産権を2件以上出願し、1件以上登録した国内18,656の企業及び大学・公共研究機関

*ここで産業財産権とは特許、実用新案、デザイン、商標を全て含める

単位：個

	母集団の大きさ	企業	大学及び公共(研)
2007年	10,202	10,050	152
2008年	11,470	11,292	178
2009年	11,987	11,792	195
2010年	13,392	13,165	227
2011年	17,440	17,220	220
2012年	18,656	18,418	238

○企業の場合、産業財産権の出願規模(共通)と業種(企業)を基準に26の集団に層化してランダム抽出

－基準年度に年平均出願10件以上または5年間登録100件以上の企業は全数調査

－基準年度に年平均出願10件未満、そして5年間登録100件未満の企業などに対

しては**割当サンプリング(quota sampling)**

※標本割当比率は企業の場合平均11%を適用

－全体標本数：3,652(1,827は全数調査、1,825は標本調査)

○大学及び公共研究機関の場合は出願及び登録件数に関係なく全数調査を実施

□標本誤差：95%信頼水準に±2.16%(企業標本層)

○標本誤差の推定式

$$1.96 \times \sqrt{((1 - (n/N)) \times (P(1 - P)/n))}$$

※nは標本数、Nは母集団の数であり、Pは(最大許容誤差)母比率である

□回答率：43.8%(企業40.6%、大学・公共(研)90.4%)

○企業全数層の回答率43.0%、標本層38.3%

□母数推定(Parameter Estimates)

○抽出された標本調査の結果と層化された各集団の母集団加重値を利用し、母集団に対する推定結果をともに提示、また全数調査の場合も回答率を調整するために加重値をりようして母数を推定する

□調査項目

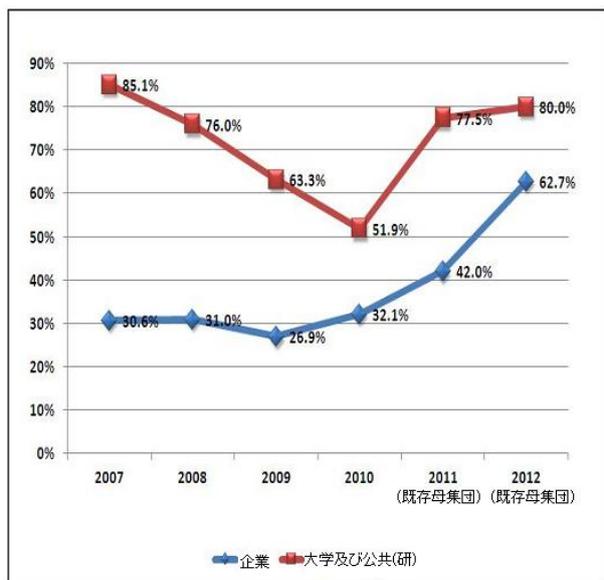
○知的財産活動の基盤となるインフラ領域と知的財産活動の段階別に知的財産の創出活動、知的財産の権利化及び保護活動、知的財産の活用活動及び知的財産権の侵害に関する事項に区分

Ⅱ.主要調査結果

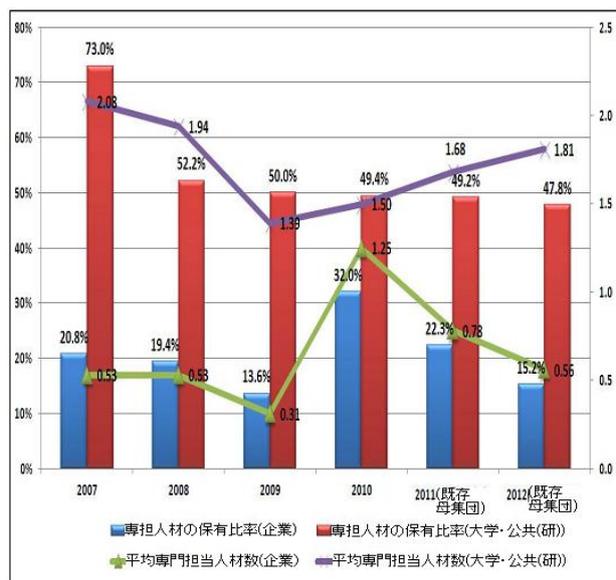
1.知的財産活動のためのインフラ

インフラ

知的財産担当組織及び人材



<知的財産担当組織保有比率の推移>



<専任人材の保有比率及び専任人材の推移>

□ 知的財産担当組織の保有比率は前年に比べて増加した企業 (55.4 % (62.7 %)、大学・公共(研)78.3 % (80.0%)¹

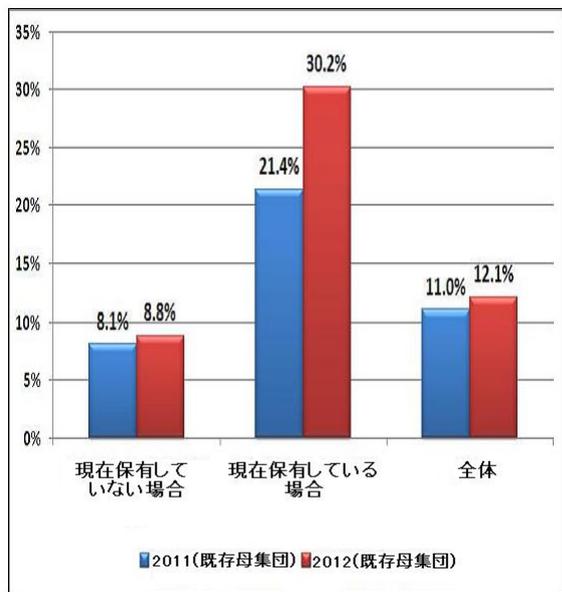
○ 企業の場合、独立専門担当部署の保有比率は 7.9%(8.8%)から 2.8%(3.6%)へと減少したが、兼任部署の保有比率が 30.7%(33.2%)から 52.6%(59.1%)へと増加

○ 重複回答企業の担当組織比率も 58.0%から 75.3%へと有意に増加

□ 知的財産を専門的に担当している人材の保有比率は企業 12.1%(15.2%)、大学・公共(研)46.7%(47.8%)で前年比減少

□ 平均知的財産の専門担当人材は企業 0.35 人(0.56 人)で前年比減少、大学・公共(研)1.80 人(1.81 人)で小幅増加

¹ 年度別の比較では2010年と母集団を同じく構成した場合の母集団推定値を入れている。括弧の中の数値は既存母集団の推定値である。



□ 知的財産専門担当人材を採用する予定のある比率は企業 10.7%(12.1%)、大学・公共(研)29.8%(29.9%)で前年比増加

□ 1年間支出した知的財産担当者への人件費/教育費は企業が 2,178(2,731)万ウォンで前年比減少、大学・公共(研)8,344(8,547)万ウォンで前年比増加

< 知的財産専門担当人材の採用予定比率(企業)

>

< 知的財産担当者の人件費/教育費 >

区分	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年 (既存母集団)	2012年 (既存母集団)
企業	3,529 万ウォン	4,936 万ウォン	4,810 万ウォン	4,654 万ウォン	3,526 万ウォン	2,731 万ウォン
大学・ 公共(研)	1億 9,225 万ウォン	7,687 万ウォン	6,091 万ウォン	5,153 万ウォン	6,754 万ウォン	8,574 万ウォン

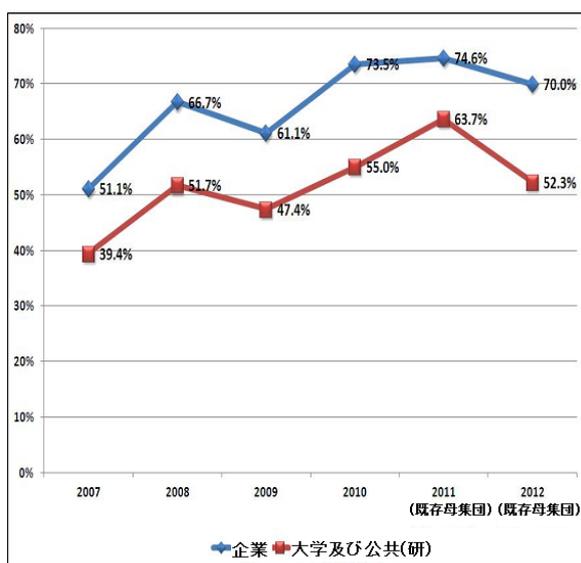
- 企業と大学・公共(研)の知的財産担当組織の保有比率は増加
 - 企業の場合は独立した専門担当部署の保有比率は減少したものの、兼任部署の保有比率が大きく増加
- しかし、企業の場合は知的財産専門担当人材の保有比率と平均専門担当人材数、担当人材に対する人件費/教育費の支出が減少
 - 今後専門担当人材の採用予定のある企業の比率は多少増加

□ 大学及び公共(研)の知的財産平均専門担当人材数、担当人材に対する人件費/教育費の支出は増加

2. 知的財産の創出活動

創出

研究開発過程における特許情報の活用状況



< 先行特許調査の実施推移 >

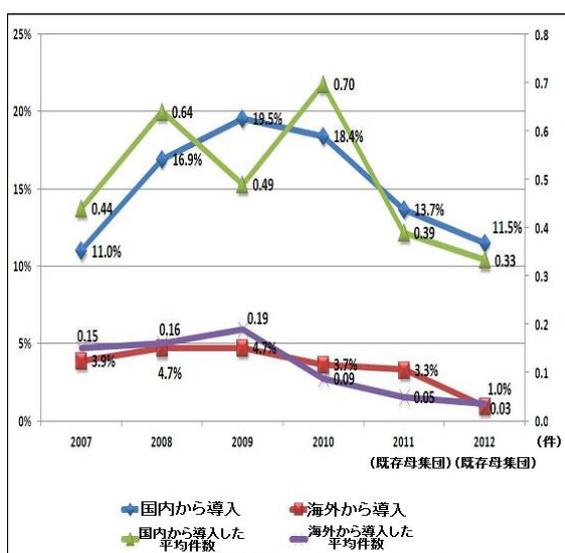
□ 先行特許調査を行う企業は 60.1% (70.0%)、大学・公共(研)51.4% (52.3%) と前年に比べて減少

□ 全体の研究開発課題のうち調査実施比率も企業 60.4% (59.6%) から 57.6% (57.0%) へと、大学・公共(研)56.9% (57.9%) から 45.8% (44.9%) に減少

□ 先行特許調査が必要であると認識している比率も減少

創出

研究開発過程における特許情報の活用状況



□ 国内から知的財産を導入した企業の比率は 9.2% (11.5%) で、2009 年から減少

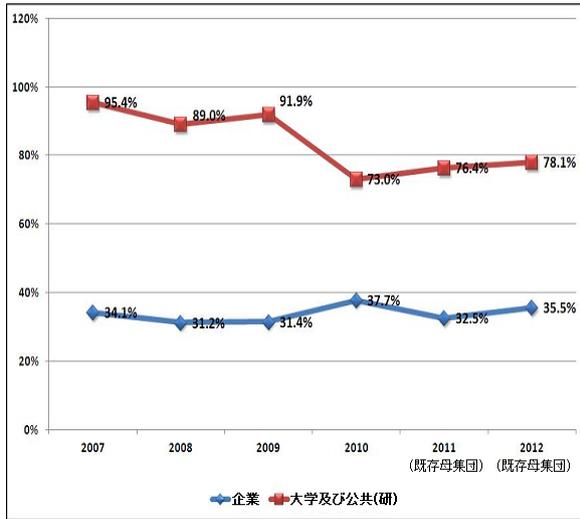
○ 平均導入件数も 2011 年 0.4 件(同一) から 2012 年 0.3 件(同一) に減少

□ 海外から知的財産を導入した企業の比率と平均導入件数も前年比減少

< 知的財産の導入推移 >

創出

職務発明補償



<職務発明補償規定の保有/活用の推移>

□職務発明の補償規定を保有・活用している企業は 26.0%(35.5%)で前年比増加、大学・公共(研)は 76.2%(78.1%)で前年比増加

○重複回答企業の職務発明補償規定の保有比率も 46.3%から 51.4%へと増加

□国内特許登録補償と出願補償を実施する企業の比率が各々91.0%と 79.8%となっており、最も多い

創出

2011年知的財産創出活動の特徴

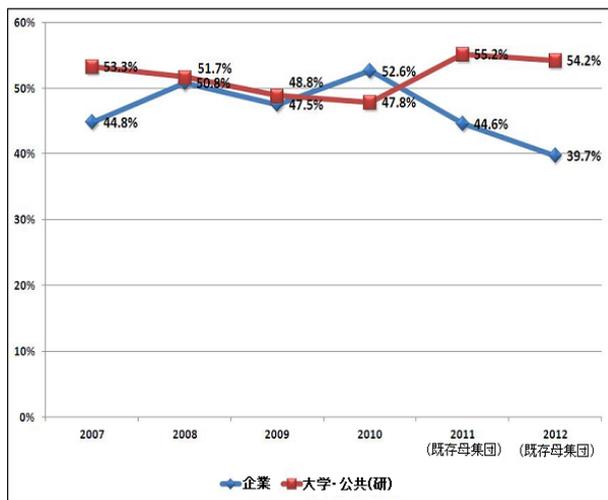
□企業と大学・公共(研)、いずれも優秀知的財産を創出するための先行特許活動及びそれに対する認識が低下

□企業の外部から知的財産を導入した成果は減少

3.知的財産の保護

保護

予備評価の実施状況



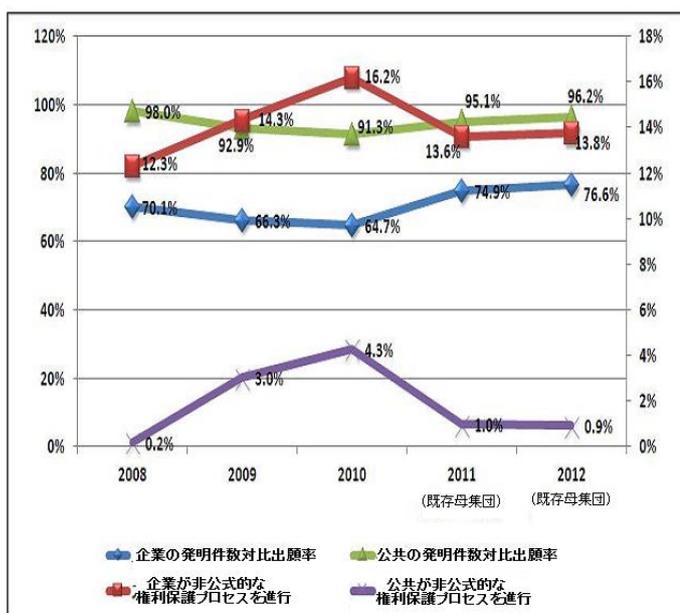
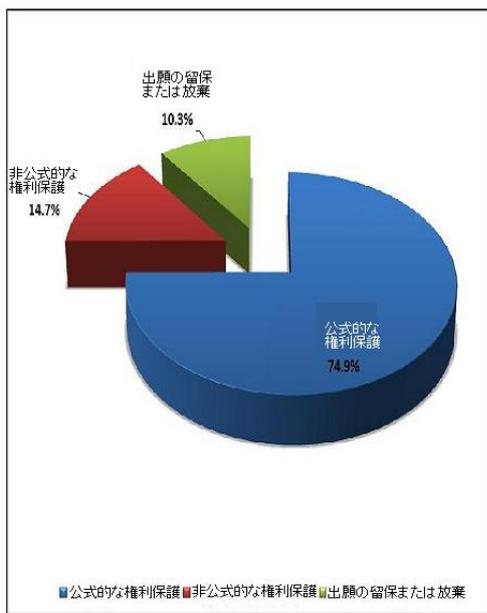
- 予備評価の実施比率は企業 33.8% (39.7%)、大学・公共(研)52.7% (54.2%)で前年比減少
- 企業、大学・公共(研)、いずれも予備評価の必要性に対する認識度が前年比減少
- 全体研究開発課題のうち実施比率は大学・公共(研)の場合 83.2%(83.1%)で前年比増加

< 予備評価実施の推移 >

保護

産業財産権の出願比率及び保護水準に対する認識

- 企業と大学・公共(研)が産業財産権の出願など公式的な権利保護プロセスを進める平均比率は全体発明のうち各々74.9%(76.6%)と 95.9%(96.2%)であり、企業と大学・公共(研)ともに前年比増加



< 研究開発成果物の保護戦略(企業) >

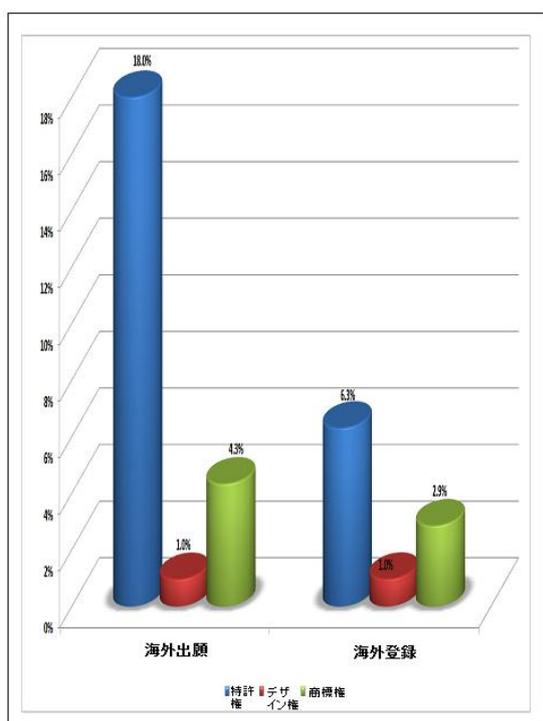
< 発明件数対比出願率の推移 >

□国内の知的財産保護水準はより強化する必要があると答えた企業と大学・公共(研)は各々73.1%(75.5%)と 86.0%(86.4%)となっており、企業は増加、大学・公共(研)は減少

保護

産業財産権の海外出願

□2011年の1年間特許権を海外出願(PCTを含む)した企業と大学・公共(研)は各々18.0%(22.7%)と 46.9%(48.3%)へと増加



< 海外出願/登録(企業) >



< 特許権の海外出願/登録の推移 >

保護

2011年知的財産保護活動の特徴

□企業の予備評価の実施比率は減少し、予備評価の必要性に対する認識度も減少しているものの、大学・公共(研)の全体研究開発課題のうち予備評価の実施比率は 2011年 77.7%(74.8%)から 2012年 83.2%(83.1%)に増加

□産業財産権の出願/登録を通じた知的財産保護体系に対する信頼度が増加

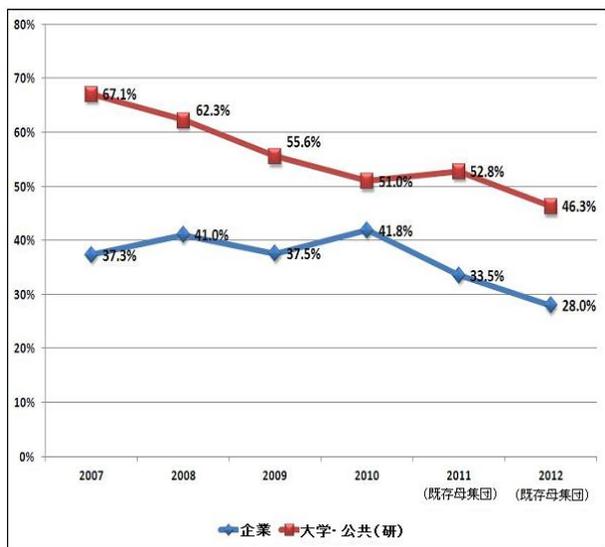
○産業財産権の出願など公式的な権利保護プロセスを進める比率が増加

○国内における知的財産保護水準が適切であるという意見は 25.5%(22.9%)

4.知的財産の活用

活用

知的財産の実査



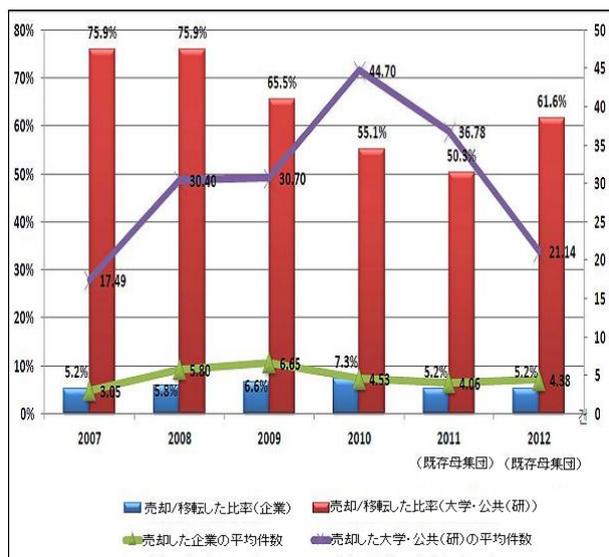
< 知的財産実査の実施比率の推移 >

□ 知的財産の実査(評価)を実施している比率は企業 24.7%(28.0%)、大学・公共(研)45.8%(46.3%)で前年比減少

□ 企業、大学・公共(研)いずれも全体発明件数のうち実施比率は減少したものの、実査の必要性に対する認識の場合企業は減少、大学・公共(研)は増加

活用

知的財産権の売却/移転状況



< 知的財産の売却/移転の推移 >

□ 2011 年度に知的財産を国内に売却/移転した比率は企業 4.1%(5.2%)で同水準を維持し、大学・公共(研)は 60.4%(61.6%)で前年比増加

□ 知的財産を売却/移転した企業の平均売却/移転件数は前年比増加、大学・公共(研)の平均売却/移転件数は前年比減少



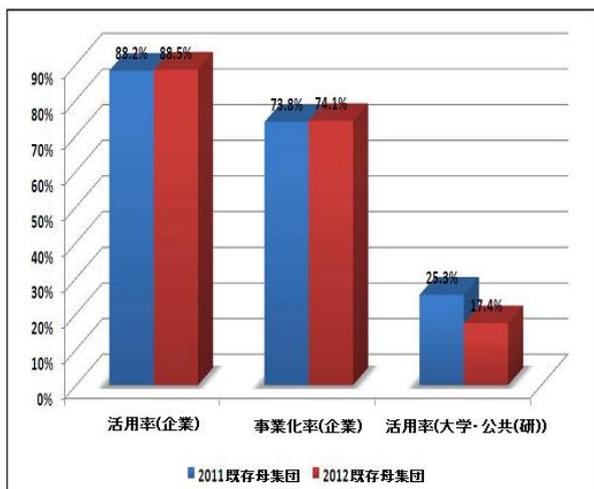
□オンライン技術取引システムの活用比率は企業 17.0% (17.6%)、大学・公共(研)45.6% (47.2%)で前年比減少

□最近 3 年間技術取引のために TLO や技術取引機関などに業務を依頼した企業の比率は前年比増加

<オンライン取引システムの活用比率の推移>

□企業における平均特許権活用率及び事業化率は 89.9%(88.5%)と 76.4%(74.1%)で前年比増加、大学・公共(研)の特許権の活用率は 17.1%(17.4%)で前年比減少

□回答企業の総特許保有件数対比活用件数及び総事業化件数の比率²は各々 79.4% (82.6%)、56.5% (60.4%)、大学・公共(研)の総保有件数対比総活用件数は 15.4% (同一)で前年比減少



<特許活用率(各企業/機関の平均)>



<特許活用率(調査対象特許合算)>

² これは多出願機関の活用率及び事業化率が加重反映された結果

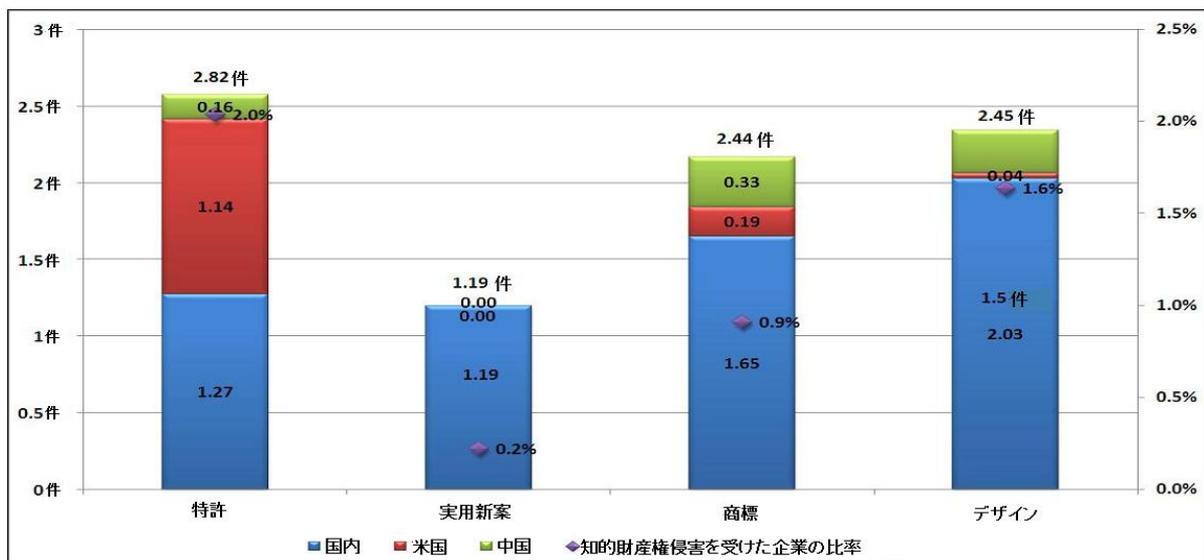
□企業の知的財産実査実施比率及びその必要性に対する認識度が減少

□企業の平均活用率(各企業の活用率の平均値)及び事業化率(各企業の事業化率の平均値)は小幅増加したものの、大学・公共(研)の活用率は減少

5.知的財産権の侵害

□2011年に1件以上の知的財産権の侵害を受けた企業は全体の4.3%(6.7%)

□2011年に特許権侵害を受けた企業は2.0%(3.3%)となっており、平均侵害件数は2.82件(2.22件)

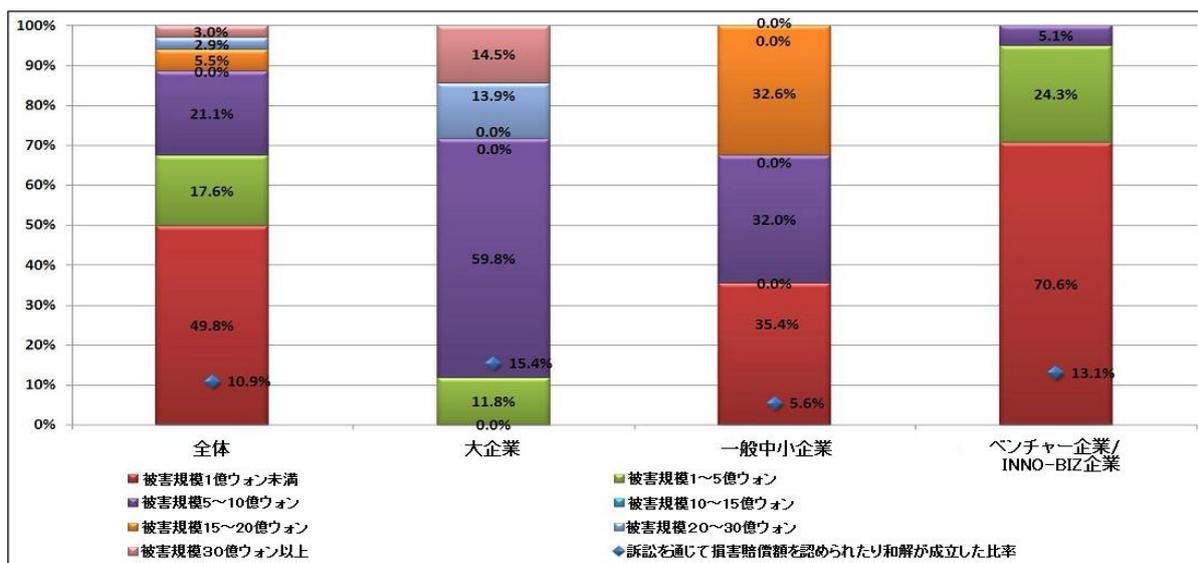


<産業財産権類型別の侵害被害件数(企業)>

□侵害件数が1件以上である企業の権利類型別の比率は特許権、デザイン権、商標権が各々40.5%(44.5%)、40.9%(30.9%)、14.3%(15.5%)

□侵害事例の侵害製品製造業者は 72.6%(80.9%)が国内企業、22.0%(14.5%)が海外企業、流通地域は国内が 85.6%(86.4%)、中国である場合が 12.8%(10.0%)、米国である場合が 10.7%(9.1%)となっている。

□2011 年知的財産権侵害を受けた企業のうち、損害賠償額を認められる、もしくは当事者間の和解が成立した比率は 10.9%(15.3%)

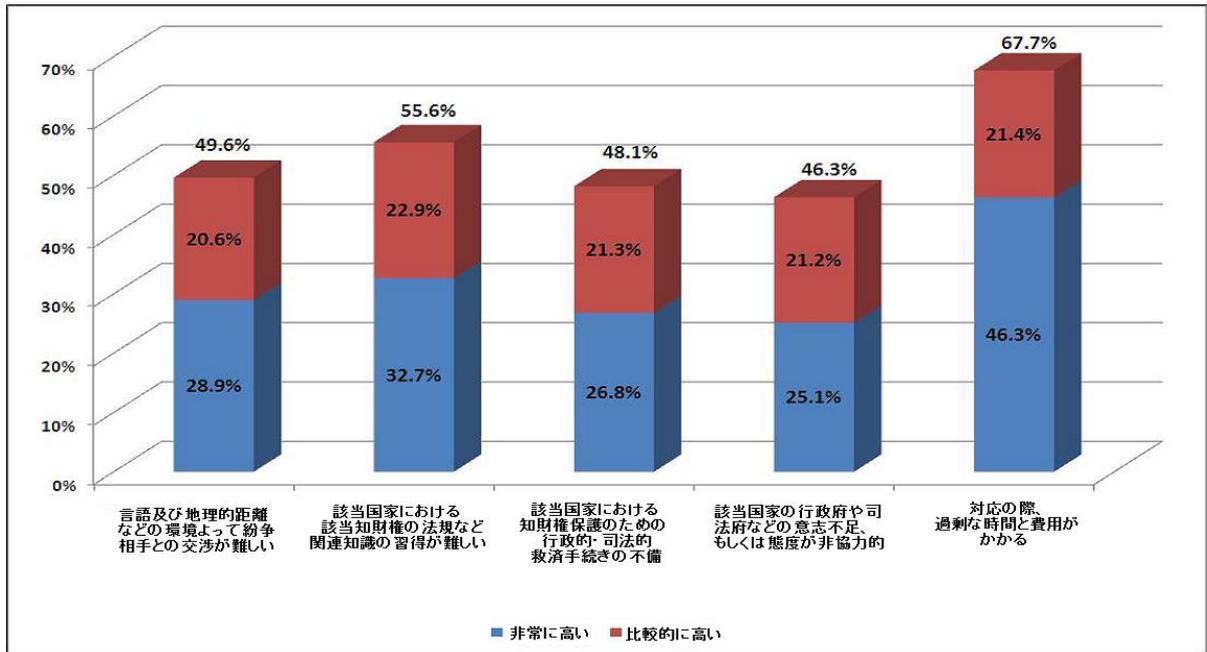


< 侵害被害の規模(損害賠償額または和解金)(企業) >

□侵害製品が市場に流通したことで営業上の被害が実際発生した場合は 57.3%(48.2%)

□実質的に営業上の被害(売上高の減少など)はないものの、期待収益の損失が予想されると回答した場合は知的財産権侵害の被害を受けた企業の 59.4%(68.0%)

□知的財産権が侵害に対応する上で難しい点として「対応の際に過剰な時間と費用がかかる」を挙げた比率は 67.7%(72.4%)



<知的財産権侵害への対応における難点(企業)>

第1章 調査の概要

第1節 調査の目的及び沿革

1.調査の目的

知的財産関連の統計は企業や大学、公共研究機関が知的財産と関連する意思決定や未来戦略の樹立において合理的な判断の根拠を提供する手段である。また、知的財産関連の統計は政府、政策研究機関など多様な需要者層で活用できる。そこで、国内企業や大学・公共研究機関の知的財産活動及びインフラなどの情報を総合的に測定・分析するため 2006 年に知的財産活動実態調査がスタートした。

知的財産活動実態調査は次のような目的で行われている。第一、国内企業と大学・公共研究機関における知的財産の創出、権利化及び保護、活用状況を調査・分析し、信頼できる情報を提供する。第二、知的財産活動の主要項目に対する年度別比較を通じて国内知的財産活動のトレンドを分析する。第三、これを通じて企業及び大学・公共研究機関の合理的な意思決定を支援するとともに、知的財産政策の樹立に反映させる。

2.調査沿革

2006 年にスタートした「企業知的財産活動調査」は活発に研究開発を行う国内企業(基準年度に 1 件以上の特許または実用新案を出願)を対象に施行された。企業を対象にした理由は、最近 15 年間(1990 年～2004 年)内国人の特許出願を企業(出願件数基準で 76.7%)が主導していることに対して(特許庁、2005)、知的財産部分において大学や公共研究機関に比べて企業を対象にした調査統計が相対的に少なかったためである。また、特許または実用新案の出願数を基準にした理由は特許出願件数が研究開発費の規模と密接に関係しているため、出願規模によって調査

対象企業を選定する方が企業の全般的な知的財産活動状況を理解する上で効果的であると判断したためである。

2007年には2006年度の調査結果を基に調査質問事項の一部を修正し、知的財産活動の段階別先行活動に対する質問事項を細分化することで、知的財産活動実態調査の統計的な安定性(stability)と妥当性(validity)を強化するための改善プロセスが行われた。また、知識の創出及び拡散をリードする公共研究機関(大学を含む)の重要性を考慮し、調査対象を従来の企業から大学・公共研究機関まで拡大した。³

2008年度には回答者の利便性と情報活用度を高めることができると判断される項目を中心に回答方法及び調査質問事項を一部修正、改編(2008年7月承認統計変更)した。従って、2007年度の知的財産活動調査結果と比較する時は調査回答方法及び質問事項の変更による差異を把握した上で使用する必要がある。2009年度の調査では実態調査結果の活用性を高めるため、一部時宜性の低い質問事項を削除し、実態調査質問事項に対する企業と政策ニーズを調査・反映した(2009年7月承認統計変更)。

また、知的財産関連の類似調査の重複実施による企業、大学・公共研究機関の回答負担を減らし、よりクオリティの高い調査のため2011年度には貿易委員会が毎年実施している「知的財産権侵害実態調査」を統合することで、知的財産の創出、保護、活用及び侵害と関連する最も広範囲な調査としての枠組みを備えることができた。

2012年には知的財産活動実態調査結果の活用性を最大化するため、再び調査項目に対する改善を図った。標本の信頼度を考慮し、調査項目に対する需要を検討して、その意見を反映することで最終調査項目を確定した。

³ そこで統計の名称も「企業知的財産活動調査」から「知的財産活動調査(The Survey of Intellectual Property -Related Activities、承認番号第13802号)」に変更された。

第2節 調査質問事項及び標本の設計

1.調査質問事項の設計

(1)知的財産活動の定義

知的財産活動は「知的財産の創出と保護、活用に関連する全ての活動」を意味するものと定義づけられる。従って、知的財産(intellectual property)の範囲を如何に設定するかによって知的財産活動実態調査で測定しようとする対象と調査領域が変わってくる。広義としての「知的財産」は発明、考案、デザイン、商標、著作物、公演など人間の創造的活動によって創られた科学技術的、文学・芸術的な成果を意味する。⁴知識基盤経済で知的財産に対する関心が高まっている理由は、知的財産が生産性の向上及び経済成長をリードする中核要因となったためである。また、企業価値の源泉も有形資産から知的財産を含む無形資産へとスピーディーにシフトしつつある。

しかし、知的財産の範囲を広義の概念に拡大する場合、統計データの集計及び調査方法における困難が予想される。即ち、測定の対象である知的財産の概念が包括的であるほど回答者の主観が介入したり、生データ(raw data)の品質が低下する矛盾関係(trade-off)に直面する可能性が高い(チェ・ソンホなど、2006)。そこで、本調査では効果的に調査を行うため、知的財産の範囲を文学・芸術的な表現と関連する著作権を除く科学技術分野の産業財産権⁵に限定し、調査質問事項によってノウハウなど新知的財産権の一部を含めることにする。

知的財産の活動は大きく創出、権利化及び侵害対応に分けられる。その主な活動は[表 1.1]のとおりである。

[表 1.1]知的財産活動の分類

⁴ 世界知的所有権機関(WIPO)と日本知的財産基本法では知的財産を「発明、著作物、公演など人間の創造的な活動による科学技術的、文学・芸術的な成果が権利として保護を受けること」と規定している。

⁵ 特許権、実用新案権、デザイン権、商標権

	目標	主要活動
創出	研究開発活動の生産性向上と価値のある知的財産の創出及び獲得	<ul style="list-style-type: none"> ・ 先行特許調査 ・ 研究開発(R&D)投資 ・ 知的財産の導入
権利化	知的財産の価値を最大化し、それに伴う費用を最小化するための権利化及び保護戦略の実行	<ul style="list-style-type: none"> ・ 予備評価 ・ 知的財産保護戦略の選択 ・ 産業財産権の国内外出願
活用	保有している知的財産の効果的な活用を通じた十分な収益の創出及び費用節減	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保有知的財産の実査評価 ・ 技術取引システムの活用 ・ 事業化または売却・移転
侵害対応	権利化された知的財産権の経済的価値を保護するため、外部からの知的財産権侵害に対応	<ul style="list-style-type: none"> ・ 知的財産権侵害のモニタリング ・ 知的財産権侵害の際、警告書の送付、司法措置などの対応

(2)主要調査内容

前述したように知的財産活動実態調査の調査質問事項は企業、大学・公共研究機関の知的財産活動と密接に連携している要素やシステムの活用状況、そしてその結果を測定する上で必要な核心内容を反映して設計しようとした。但し、出願人別国内産業財産権の出願件数などのように特許庁を中心に既に調査・公表されている項目は調査項目から除外している。⁶

[表 1.2]知的財産活動実態調査の主要調査項目

⁶ このような統計資料は知的財産統計年報(特許庁)、韓国の特許動向(特許情報院)などから確認できる。

分類	変数グループ	主要調査項目
一般事項 及び インフラ	-	会社形態、輸出状況** 従業員数及び売上高** 研究開発人材及び研究開発費 知的財産担当組織及び人材、業務内容 知的財産サービスの活用費用
知的財産 創出活動	先行活動	先行特許調査など特許情報の活用 (活用状況、必要性、担当人材など)
	戦略	知的財産創出のための研究開発活動及び今後の戦略 外部からの知的財産導入のための投資と主要獲得源** 職務発明補償
	算出	外部からの知的財産導入の実績**
	政策需要	効果的な知的財産創出のために必要な政策支援
知的財産の 権利化及び 保護活動	先行活動	予備評価(活用状況、必要性、担当人材など)
	戦略	知的財産保護(研究成果の専有)戦略の活用度 知的財産管理及び保護に関する認識度 出願/審査/維持費用
	算出	産業財産権の国内出願、登録実績* 産業財産権の海外出願、登録実績 知的財産の模倣被害**
	政策需要	効果的な知的財産保護のために必要な政策支援
知的財産 活用活動	先行活動	保有している知的財産に対する実査 (活用状況、必要性、担当人材など)
	戦略	技術取引機関との協力 技術取引システムの活用度 特許技術事業化における難点及び所要時間
	算出	産業財産権の活用状況 知的財産の有償実施許諾または売買契約の成果

	政策需要	効果的な知的財産活用のために必要な政策支援
知的財産 侵害及び 紛争	-	知的財産権の侵害及び被害規模 知的財産権侵害に対するフォローアップ 知的財産権紛争関連の難点 知的財産権侵害に対応するために必要な政府政策

* 特許庁の産業財産権出願統計資料を活用

** 企業に対してのみ調査

まず、調査項目は知的財産活動の基盤となるインフラ領域(知的財産人材、知的財産管理システムなど)と知的財産活動の段階別に知的財産創出活動に関する事項、知的財産権利化に関する事項、知的財産活用活動に関する事項、知的財産権侵害の対応に関する事項に区分して構成した。また、段階別の知的財産活動を先行活動、戦略(推進過程)、政策需要、算出に細分化して配置することで、企業及び大学・公共研究機関で行われる知的財産活動の構造や特性をより深く理解できるようにした。調査項目別の主な調査質問事項は[表 1.2]のとおりである。

2.標本設計

(1)母集団及び標本規模

2010年までの「知的財産活動実態調査」と「知的財産権侵害実態調査」の母集団及び標本は[表 1.3]のように相異なる。「知的財産活動実態調査」の場合は知的財産活動を活発に進めている企業及び機関が調査対象であるため、最近2年間特許及び実用新案を出願した企業及び大学・公共(研)を母集団に入れてきた。また、「知的財産権侵害実態調査」は侵害対象の知的財産権を保有する企業を調査対象としているため最近5年間産業財産権を登録した企業を母集団に入れた。

[表 1.3]既存知的財産権侵害実態調査と母集団の比較

調査区分	母集団	標本
知的財産活動 実態調査 (特許庁)	・ 2 年間(2007～2008) 2 件以上の 特許及び実用新 案 出願企業、大学・公共 (研)	・ 全数調査 ：10 件以上特許及び実用新案 を出願した企業(2 年間) ・ 標本調査 ：出願 10 件未満の企業を対象 に業種を分類して標本を抽出(20～35%)
知的財産権 侵害実態調査 (貿易委員会)	・ 直前 5 年間(2005～ 2009)1 件以上 産業財産権 (特許、実用新案、商 標、デザイン)を登録し た企業	・ 全数調査 ：100 件以上産業財産権を登録 した企業(5 年間) ・ 標本調査 ：産業財産権登録件数別に 9 つ のグループに分け、登録件数加重が適用さ れた分布によって比例割当

2011 年調査では[表 1.3]のように母集団が相異なる「知的財産活動実態調査」と「知的財産権侵害実態調査」が統合されたことで母集団変更の必要に迫られた。2011 年調査では現在活発な知的財産活動を行うと同時に、侵害対象の知的財産権を保有している企業及び大学・公共(研)を母集団に含める必要があった。そこで、2 年間(2008～2009)2 件以上の産業財産権を出願し、同時に 5 年間(2006～2010)1 件以上登録した企業及び大学・公共(研)を母集団に含めた。出願対象を既存の特許、実用新案から最近産業財産権としての価値が高まりつつあるデザインと商標までその範囲を拡大している。2012 年調査では 2011 年と同じ母集団を対象にしている。

母集団に含まれる大学・公共研究機関は「技術移転及び事業化促進に関する法律」第 2 条に基づいて国公立試験研究機関、科学技術分野政府出捐研究機関、特定研究機関、専門生産技術研究所、非営利法人及び団体、国公立大学及び私立大学を意味し、公企業及び地方自治団体は除外している。

2012 年度調査における母集団の規模は企業が 18,418 社、大学・公共研究機関が 238 個である([表 1.4])。母集団に含まれる企業、大学・公共研究機関のうち 20 件(年平均 10 件以上)の産業財産権を出願したり、100 件以上(年平均 20 件以上)を登録⁷した企業は 1,827 社である。

⁷ 全数調査の対象は既存調査での基準を適用する。全数調査対象標本の分布は[表1.5]のと

[表 1.4]年度別母集団の規模

	母集団の規模	企業	大学及び公共(研)
2007年	10,202	10,050	152
2008年	11,470	11,292	178
2009年	11,987	11,792	195
2010年	13,392	13,165	227
2011年	17,440	17,220	220
2012年	18,656	18,418	238

標本抽出のために産業財産権の出願規模と業種(企業)、機関類型(大学・公共研究機関)を基準に2次層化した後、最終標本機関を選定している。母集団に含まれる企業は2007年12月28日改正告示された第9次韓国標準産業分類表(KSIC)を基準に13業種に区分している。⁸産業財産権の出願及び登録規模と業種(企業)、機関類型(大学・公共研究機関)に区分された母集団の分布は[表 1.5]、[表 1.6]のとおりである。

[表 1.5]企業母集団の分布

単位：個、%

	20件以上出願(or)100 件以上登録	20件未満出願 (and)100件未満登録	合計	比重
農林水産及び鉱業、飲食 料及びタバコ製造業	85	606	691	3.8
卸及び小売業	159	2,178	2,337	12.7
事業サービス業、通信業	142	1,520	1,662	9.0
金融及び保険業	28	108	136	0.7

おりである。

⁸ 業種分類と韓国標準産業分類表(KSIC)との連携表は付録1を参照

建設業	110	1,191	1,301	7.1
その他サービス業	111	765	876	4.8
繊維製品、衣服、靴製造	74	503	577	3.1
紙及び印刷、出版業	130	1,326	1,456	7.9
化学産業	215	1,310	1,525	8.3
鉄鋼及び金属産業	47	572	619	3.4
電気電子産業	175	1,314	1,489	8.1
機械産業	494	4,702	5,196	28.2
その他製造業	57	496	553	3.0
合計	1,827	16,591	18,418	100.0
比重	9.9	90.1	100.0	

[表 1.6]大学・公共研究機関母集団の分布

単位：個、%

	20 件以上出願(or)100 件 以上登録	20 件未満出願 (and)100 件未満登録	合計	比重
国公立大学	33	8	41	17.2
私立大学	72	74	146	61.3
政府出捐(研)	20	1	21	8.8
その他公共研究機関	17	13	30	12.6
合計	142	96	238	100.0
比重	59.7	40.3	100.0	

各業種及び機関類型によって母集団の数が決まった後、業種(企業)内での出願規模別割当は基準年度に 20 件以上(年平均 10 件以上)の産業財産権を出願したり、

100 件以上(年平均 20 件以上)登録した企業は全数を調査対象としている。5 年間登録件数別全数調査対象の比率は[表 1.7]のとおりである。

[表 1.7]企業登録件数別の全数調査対象の比率

登録件数	全体企業数	全数調査対象企業数	全数調査の比率 (%)
10～19 件	2589	270	10.4
20～29 件	844	288	34.1
30～39 件	370	181	48.9
40～49 件	205	130	63.4
50～59 件	149	103	69.1
60～69 件	110	87	79.1
70～79 件	83	66	79.5
80～89 件	49	45	91.8
90～99 件	47	39	83.0
100 件以上	383	383	100.0

また、基準年度に 20 件未満(年平均 10 件未満)の産業財産権を出願した企業などに対しては割当((quota sampling)⁹)を行っている。業種(企業)によって区分された各集団に対する標本割当比率は平均 11%を適用している。業種(企業)別に割当てられた標本の分布は[表 1.8]のとおりである。

[表 1.8]企業標本の分布

	全数調査企業の数	割当てられた 標本企業の数	総標本企業の数
農林水産及び鉱業、飲食 料及びタバコ製造業	85	66	151

⁹ サンプリング方法のうち母集団の大きさが比較的に大規模である場合適した非確率標本抽出方法の一つである。母集団を幾つかの要因で分類し、分類した各階層の大きさに比例して標本数を決める。

卸及び小売業	159	227	386
事業サービス業、通信業	142	167	309
金融及び保険業	28	12	40
建設業	110	129	239
その他サービス業	111	86	197
繊維製品、衣服、靴製造	74	58	132
紙及び印刷、出版業	130	138	268
化学産業	215	153	368
鉄鋼及び金属産業	47	68	115
電気電子産業	175	146	321
機械産業	494	520	1,014
その他製造業	57	55	112
合計	1,827	1,825	3,652
比重	50.0	50.0	

(2)母集団推定

本報告書では 3,890 の企業及び大学・公共研究機関を標本調査して収集された結果を基に母数推定(parameter estimates)を行い、その結果を 2 章(企業)及び 3 章(大学・公共研究機関)で提示している。母集団推定のためには標本を抽出した業種及び機関類型と出願規模別に層化された 34 の集団(企業 26 社、大学・公共研究機関 8 つ)に対して回収されたアンケート調査の回答を集計した後、これを母集団規模まで拡大して母集団値を推定している。その際、次のような方法で作られた加重値を活用している。

$$W_{ij} = \frac{N_{ij}}{n_{ij}}$$

ここで N_{ij} は層化された各集団に含まれる母集団の数であり、 n_{ij} は層化された各集団別回答企業の数である。また、既存実態調査結果との連続的な比較のため、本文の

中で母集団を 2010 年以前と類似するよう構成(基準年度に特許、実用新案 2 件以上出願した企業、大学・公共研究機関)した時の推定値を別途括弧で表示している。

本報告書に収録されている統計表では調査結果を企業の類型¹⁰(大企業、一般中小企業、ベンチャー/Inno-biz 企業)、大学・公共(研)の類型(私立大学、国公立大学、政府出捐研究機関、その他公共研究機関)に分けて提示している。また、出願規模による差異を示すため、産業財産権出願件数別¹¹の数値を別途提示している。

¹⁰ 製造業の場合、常時従業員数が300人以上で資本金が80億ウォンを超える場合は大企業、ベンチャーまたはInno-biz認証を受けた場合はベンチャー/Inno-biz企業、その他は一般中小企業として区分する。

¹¹ 年10件未満、11～20件、21～60件、61件以上で区分

第3節 調査方法及び回答率

1.調査方法

本調査の調査対象期間は 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 12 月 31 日までを基準とし、12 月決算でない場合は質問事項別に回答の利便性を考慮して 2011 年(1 月～12 月)または直前会計年度のうち一つを選択して回答できるようにしている。調査質問事項の中で先行特許調査、産業財産権の活用状況(収入と支出を除く)、知的財産担当人材の状況などの質問事項は回答時点を基準にしている。

調査方法は 3 段階ハイブリッド方法(Hybrid Method)を活用している。1 段階の定性調査では企業、大学・公共研究機関の知的財産担当で構成された諮問グループを構成し、フォーカスグループインタビュー(Focus Group Interview)を実施している。これを通じて調査票の回答利便性及び活用性を検討した。

[表 1.9]2 段階アンケート調査のプロセス及び方法

調査プロセス	調査方法
調査準備	企業情報自動確認システムを通じて調査対象企業の連絡先の有効性を一括点検→調査効率性の改善及び調査期間の短縮
アンケート調査	標本選定企業を対象にメール、FAX、電話調査を実施 回収率を高めるための調査対応をマニュアル化(調査拒否、理解不足など)
資料エディティング	1 次資料を取り集める 項目間、回答内容間でのロジックの合理性を確認
補完調査及び資料入力	異常回答値に対して専門調査員が補完調査 エディティング及び補完調査が全て完了した資料に限りデータ入力

2 段階ではアンケート調査を行った。アンケート調査期間は 2012 年 8 月 20 日から 11 月 23 日まで約 3 ヶ月間である。調査は郵便アンケート調査(Mail Survey)を基本調査方法として使用し、韓国知識財産研究院のホームページを通じてアンケート用紙を

直接ダウンロードして作成できるようにした。調査のためにまず対象となる企業及び大学・公共研究機関との事前接触を通じて主たる回答者を決め、郵便でアンケート用紙を発送する方法を進めた。本調査の主要回答者は各企業の特許関連専担部署及び関連部署、大学の産学協力団、技術移転センター(TLO)などの関連業務担当者である。調査拒否の場合、杜撰な回答である場合、回答が無い場合は次のマニュアルに従って対応した。

[表 1.10]調査拒否及びアバウトな回答である時の対応策

	事例	対応策
調査 拒否	内容が 理解できない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 知的財産分野の産業分析専門家で構成された調査支援チームが調査の目的、調査のメリット、事業内容及び回答方法に対して再び説明 ・ 調査支援チームの説明の後に同じ理由で調査を拒否する場合、意図的な調査拒否と看做して調査対象企業から外す
	回答できない 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 企業が一定規模以上である場合、調査分野別に回答可能な部署が違いため、担当者の適正性を再確認 ・ 調査内容が業種及び規模に合わないため回答できない場合、業種を再確認して適した調査用紙を発送、小規模な企業である場合は該当事項のある質問事項のみ回答できるように案内
	調査対象に 適した企業で はない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査支援チームが取扱い製品やサービスを確認し、適合性を判断 ・ 適合した企業として判定された場合、その事由を企業に伝えて調査参加を再要請する
	調査に応じる 時間がない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査対象企業が以前調査回答企業であったり、業種別有効標本を確保するための必須調査対象である場合、前年度の調査回答企業の場合、既存回答資料の変動事項のみ修正を要請 ・ 上記の調査条件に対しても拒否する場合、調査対象

		企業から外す
	特別な事由のない調査拒否	<ul style="list-style-type: none"> ・調査目的及び調査後企業に与えられるメリット(謝礼品)を再び説明 ・説明の後も拒否する場合、調査対象企業から外す
杜撰な回答	回答値が会社規模(売上状況及び人材状況)に比べて過大/過小値である場合	<ul style="list-style-type: none"> ・実査担当研究院がエディティング過程で選別する ・企業情報 DB 内の該当企業情報を詳細検討し、回答値の有効性を判断 ・異常値として判断された場合、関連質問事項のみ再調査を実施
	類似した質問事項に相反する内容の回答である場合	<ul style="list-style-type: none"> ・実査担当研究院がエディティング過程で選別 ・質問事項間の回答有意性を確認した後、異常値として判断された場合、該当質問事項のみ電話で再調査を実施 ・回答が全体的に連結性がなく適当に作成されたものと判断された場合、該当回答用紙の廃棄及び再調査または代替企業を調査

[表 1.11]回答が無い場合の対応策及び欠測値の補正方法

事例	対応策
企業秘密に該当すると判断して回答しない質問事項	<ul style="list-style-type: none"> ・調査機関の対外認知度及び信頼性に対して説明した後、再び協力を求めると同時に調査結果は全体統計としてのみ活用されることを強調 ・必要な場合は訪問を通じて信頼性を確認した後補強調査 ・保有している財務資料 DB を活用して一部補完
作成途中に回答を中断した場合	<ul style="list-style-type: none"> ・会社の基本(概要)情報のみ回答した場合と調査の 50%以上回答しなかった場合、該当アンケート用紙は廃棄⇒代替企業を調査 ・アンケートに対する回答が 50%未満であるものの必須調査項目には答えた場合、電話で再調査を実施

欠測値の補正方法	・単一確率代入法(Single Stochastic Imputation) ¹² を活用
----------	--

最後の3段階では活発な知的財産先行活動を行っている企業、知的財産導入及び売却企業、知的財産権侵害事例企業を対象に担当研究員が調査対象を直接訪問して深層面接(Depth Interview)を行っている。これを通じて具体的な知的財産先行活動及び売却/移転方法、具体的な知的財産権の被害内容及び事件経過などを把握した。

2.調査結果

調査対象である3,652の機関のうち、不渡りや廃業、欠番などによって発生した標本損失を除外した有効標本規模¹³を基準にした回答率¹⁴は43.8%となっており、前年度回答率の42.1%より1.7%p増加となっている。企業は1,092社が回答して40.6%、大学・公共研究機関は169機関が回答して90.4%の回答率となっている。企業業種別有効標本の規模及び回答率は[表 1.12]と[表 1.13]のとおりである。

[表 1.12]有効標本の規模及び回答率

単位：個、%

区分	抽出した標本	欠番/その他	該当無し	不渡/廃業	重複	有効標本	事前拒絶	回答企業	回答率
企業	3,652	537	0	19	2	3,094	405	1,092	40.6
大学・公共(研)	238	0	0	1	0	237	50	169	90.4

[表 1.13]業種別有効標本の規模及び回答率

単位：個、%

¹² 平均代入法で観測された資料を基に推定された統計量で欠測値を代入する時、ある適切な確率値を与えた後代入する方法、この方法は推定量の標準誤差が過小推定される問題が補完できる。

¹³ 有効標本規模 = {[抽出した標本規模] - ([欠番及びその他] + [該当無し] + [不渡/廃業] + [重複])}

¹⁴ 回答率 = {[実際の回答規模] ÷ ([有効標本規模] - [事前拒絶])} × 100

業種名	抽出した標本	欠番/ その他	該当 無し	不渡 /廃業	重複	有効 標本	事前 拒絶	回答 企業	回答 率
農林水産及び鉱業、飲 食料及びタバコ製造業	151	14	0	0	1	136	15	54	44.6
卸及び小売業	386	88	0	4	0	294	16	76	27.3
事業サービス業、通信業	309	50	0	0	0	259	83	70	39.8
金融及び保険業	40	8	0	0	0	32	9	13	56.5
建設業	239	24	0	0	0	215	30	96	51.9
その他サービス業	197	47	0	1	0	149	25	40	32.3
繊維製品、衣服、靴製造	132	25	0	2	0	105	32	25	34.2
紙及び印刷、出版業	268	60	0	2	0	206	47	58	36.5
化学産業	368	30	0	1	0	337	35	135	44.7
鉄鋼及び金属産業	115	7	0	2	0	106	12	38	40.4
電気電子産業	321	63	0	4	0	254	33	93	42.1
機械産業	1014	111	0	3	1	899	55	357	42.3
その他製造業	112	10	0	0	0	102	13	37	41.6

また、業種別、機関類型別回答機関の分布は次の[表 1.14]、[表 1.15]のとおりである。

[表 1.14]業種別、企業類型別回答企業の分布

区分		全数層 (企業数)	標本数 (企業数)	合計 (企業数)
業種	農林水産及び鉱業、飲食料及 びタバコ製造業	32	22	54
	卸及び小売業	33	43	76

	事業サービス業、通信業	30	40	70
	金融及び保険業	7	6	13
	建設業	51	45	96
	その他サービス業	18	22	40
	繊維製品、衣服、靴製造	14	11	25
	紙及び印刷、出版業	36	22	58
	化学産業	85	50	135
	鉄鋼及び金属産業	18	20	38
	電気電子産業	49	44	93
	機械産業	179	178	357
	その他製造業	23	14	37
企業 類型	大企業	224	50	274
	一般中小企業	117	169	286
	ベンチャー企業/INNO-BIZ企業	234	298	532
	合計	575	517	1,092

[表 1.15]大学・公共(研)類型別回答機関の分布

区分	全数 (機関数)	標本 (機関数)	合計 (機関数)
国公立大学	24	3	27
私立大学	56	52	108
政府出捐(研)	17	1	18
その他公共研究機関	7	9	16
合計	104	65	169

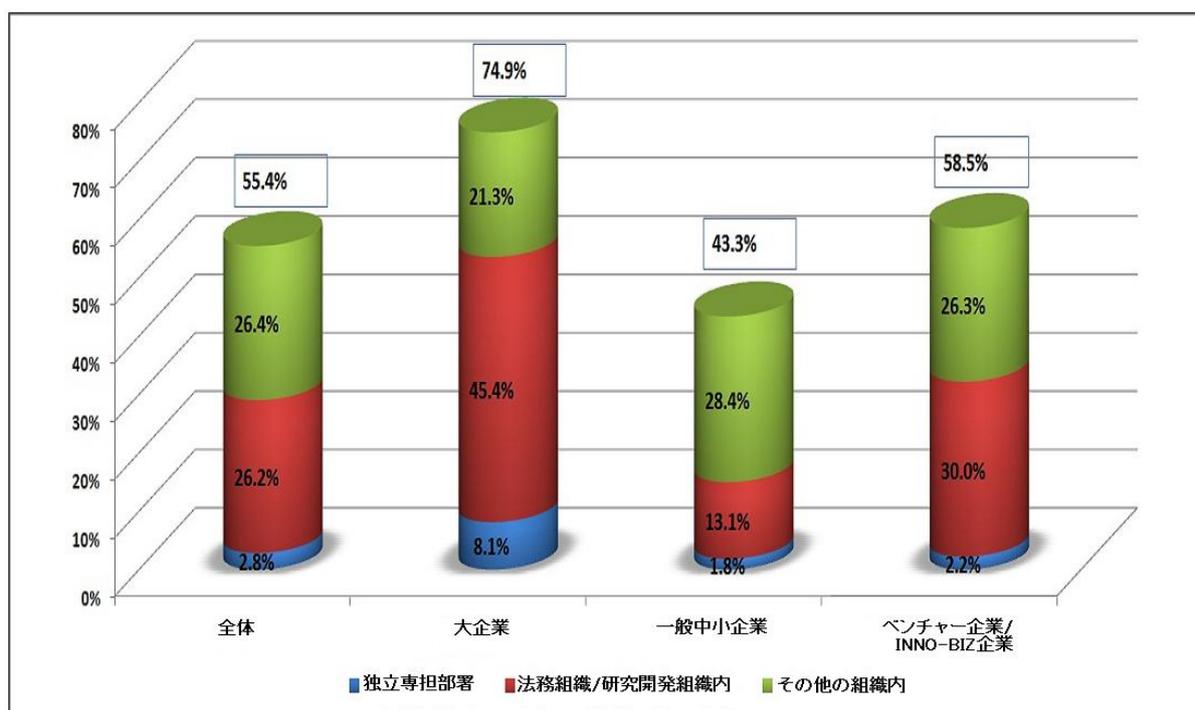
第2章 企業の知的財産活動

本章では標本調査の結果を基に母集団全体を推定した結果を提示している。そのために本調査では母集団を業種及び出願規模によって層化した 26 の企業集団に区分し、各集団別に回収されたアンケートの回答を集計した後、これを母集団規模に拡大して母集団値を推定している。

第1節 知的財産活動のインフラ

1. 知的財産担当組織及び人材

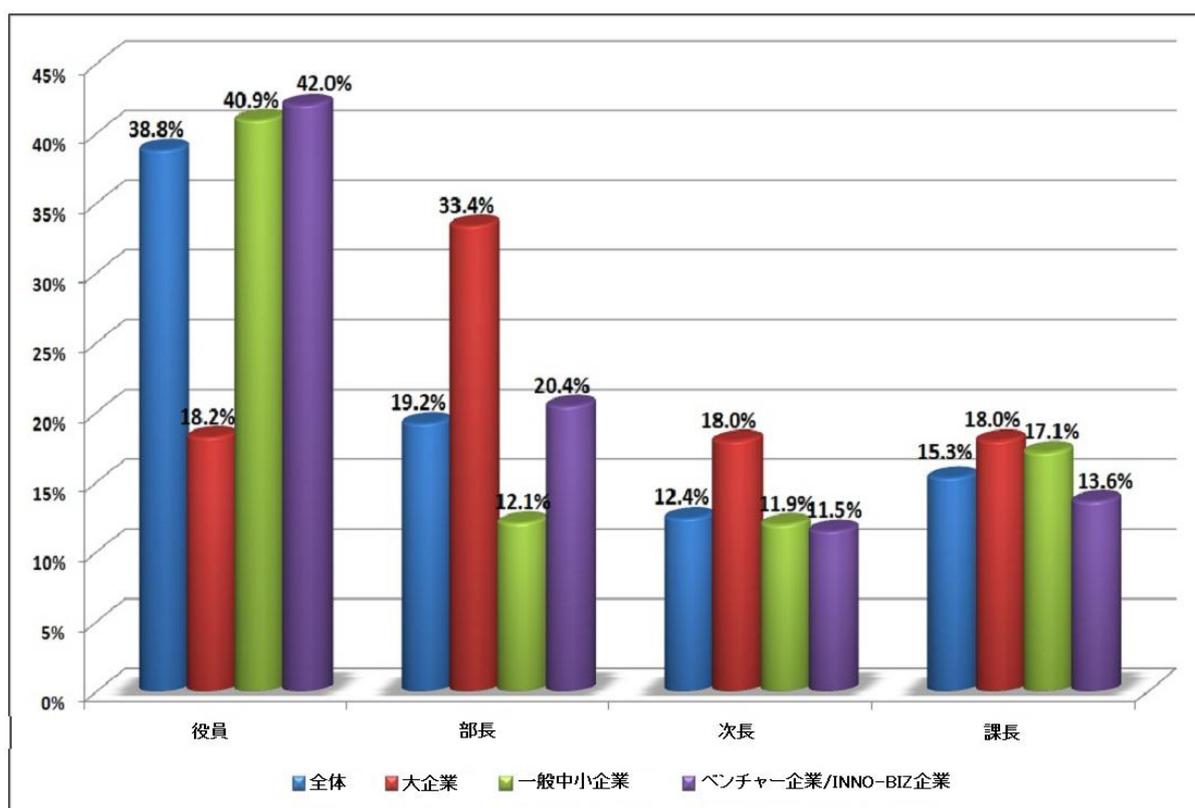
母集団に属している企業の 55.4%(62.7%)は知的財産の管理を担当する組織を保有していることがわかった([図 2.1])。担当組織の形態別では、独立した専門担当部署を保有している比率が 2.8%(3.6%)であり、兼任組織¹⁵の保有比率である 52.6%(59.1%)に比べて低いことがわかる。



[図 2.1] 知的財産担当組織の保有状況

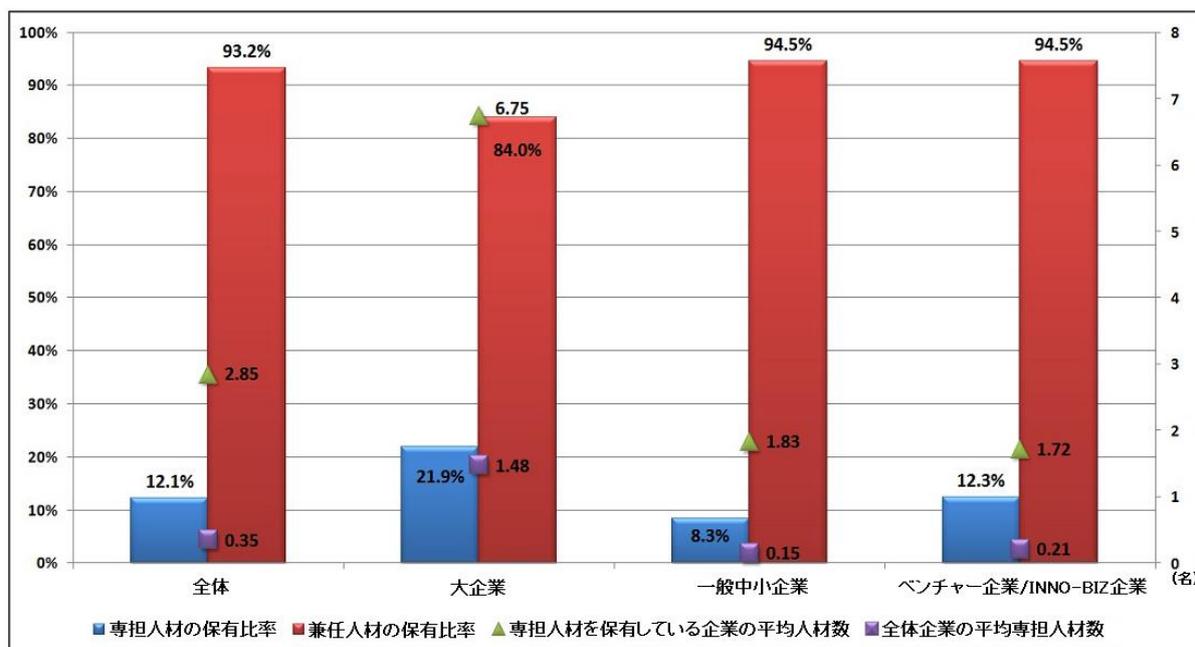
¹⁵ 法務組織や研究開発組織、その他組織内に知的財産担当組織が存在

企業類型別では、大企業の 74.9%(81.8%)、中小企業の 43.3%(56.0%)、ベンチャー企業の 58.5%(59.9%)が知的財産担当組織を保有していることがわかった。特に、大企業の場合は知的財産担当組織が独立専門担当組織である比率が 8.1%(9.0%)であり、知的財産担当組織の中で独立専門担当部署である比率が他の企業類型に比べて相対的に高いことがわかる。



[図 2.2]知的財産担当組織総括者の地位

知的財産担当組織総括者の地位と関連する分布は[図 2.2]のとおりである。知的財産担当組織総括者の地位が役員である比率は 38.8%と最も高く、部長 19.2%、次長 12.4%、課長 15.3%の順となっている。特に、ベンチャー企業の場合は知的財産担当組織総括者の地位が役員である場合が全体の 42.0%と大企業及び中小企業より高いことがわかる。出願件数別では、知的財産担当組織総括者の地位が役員である比率は出願件数が多い多出願企業であるほど低くなる傾向(年平均 10 件未満出願企業の 40.1%、年平均 61 件以上出願企業の 18.7%)となっている。



[図 2.3]知的財産担当人材の保有状況

専ら知的財産関連業務だけを担当する専門人材¹⁶を保有している比率は全体の12.1%(15.2%)、その他業務を並行する兼任人材を保有している比率は全体の93.2%(90.7%)となっている([図 2.3])。企業類型別では、大企業の21.9%(30.1%)、中小企業の8.3%(9.1%)、ベンチャー企業の12.3%(13.3%)が1名以上の知的財産専任人材を保有していることがわかる。

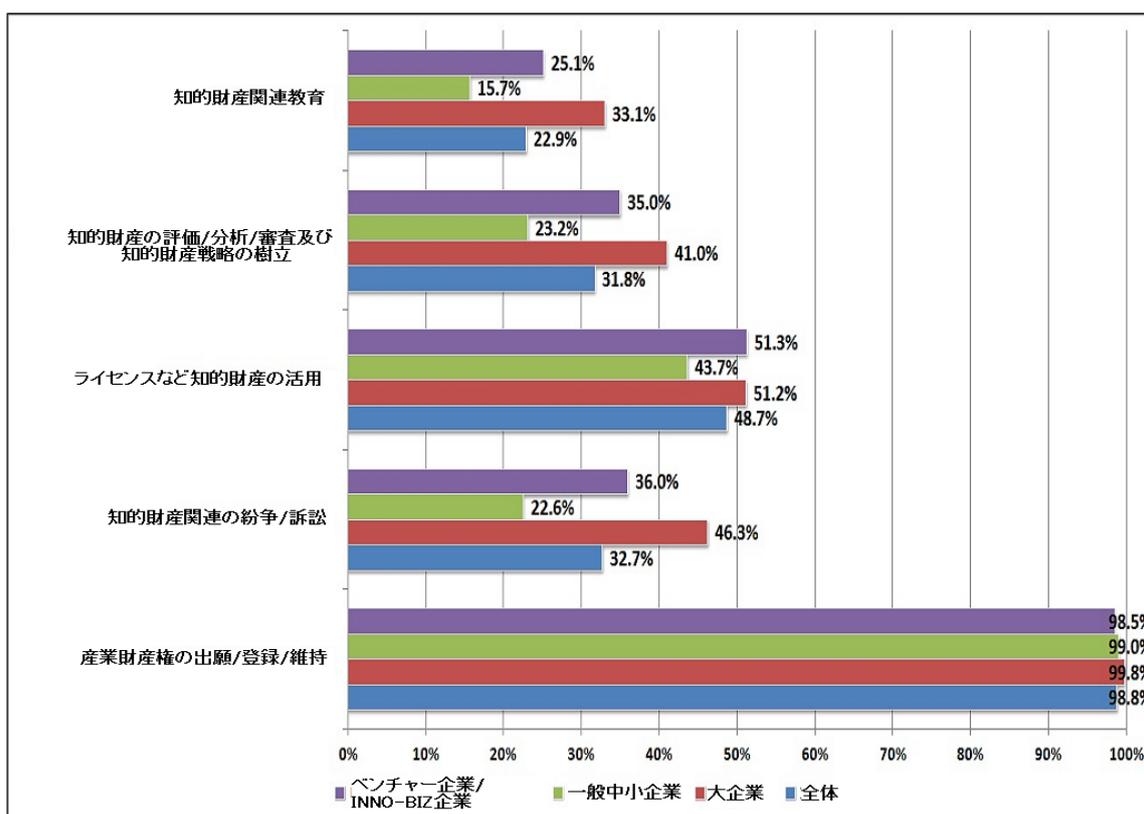
全体企業の平均専任人材数は0.35名(0.56名)であり、専任人材を保有している企業平均は2.85名(3.68名)となっている。専門担当人材を保有している企業の平均人材数は大企業が6.75名(7.43名)、中小企業が1.83名(2.13名)、ベンチャー企業が1.72名(同一)となっており、大企業の平均専任人材数が多いことが確認できる。人材に対する絶対的数値の他に企業の知的財産関連活動規模を考慮して専任人材の投入レベルを比較するため、「知的財産管理への取組み(人材投入)」¹⁷レベルの把握に取り組んだ。

¹⁶ 知的財産担当人材は企業内で特許ポートフォリオ分析などの知的財産戦略企画、国内外産業財産権の出願及び登録・維持管理、知的財産権動向調査、特許侵害関連の対応及び訴訟業務、知的財産権の販売またはライセンス交渉及び技術料管理などの業務を担当する人材を意味し、この中で知的財産専門担当人材はこのような知的財産関連業務だけを専門的に行う人材を意味する。

¹⁷ 知的財産管理への取組み(人材投入)：各々[(企業の研究開発人材対比専門担当人材数)*100]、[産業財産権保有件数対比専門担当人材数]で計算

企業の知的財産管理への取組み(人材投入)を分析した結果、企業の研究開発人材対比専門担当人材数の比率は大企業 0.99%、中小企業 3.47%、ベンチャー企業 3.93%となっており、企業の産業財産権権利保有件数¹⁸対比専門担当人材数の比は大企業 0.41、中小企業 1.33、ベンチャー企業 1.64 となっていることから、ベンチャー企業が知的財産を管理するために人材投入に力を入れていることが窺える。

出願件数別では、年平均 61 件以上出願する企業の専門担当人材は平均 10.0 名で、出願件数が多い企業であるほどその数が増加している。¹⁹しかし、兼任人材の場合は出願件数が多い企業であるほどその数が減少している。²⁰これは管理しなければならない知的財産が多い企業ほど兼任人材よりは専門性のある専門担当人材を置いているものと解釈できる。



[図 2.4]知的財産関連業務を行っている企業比重

注. 知的財産担当人材を保有している場合である。

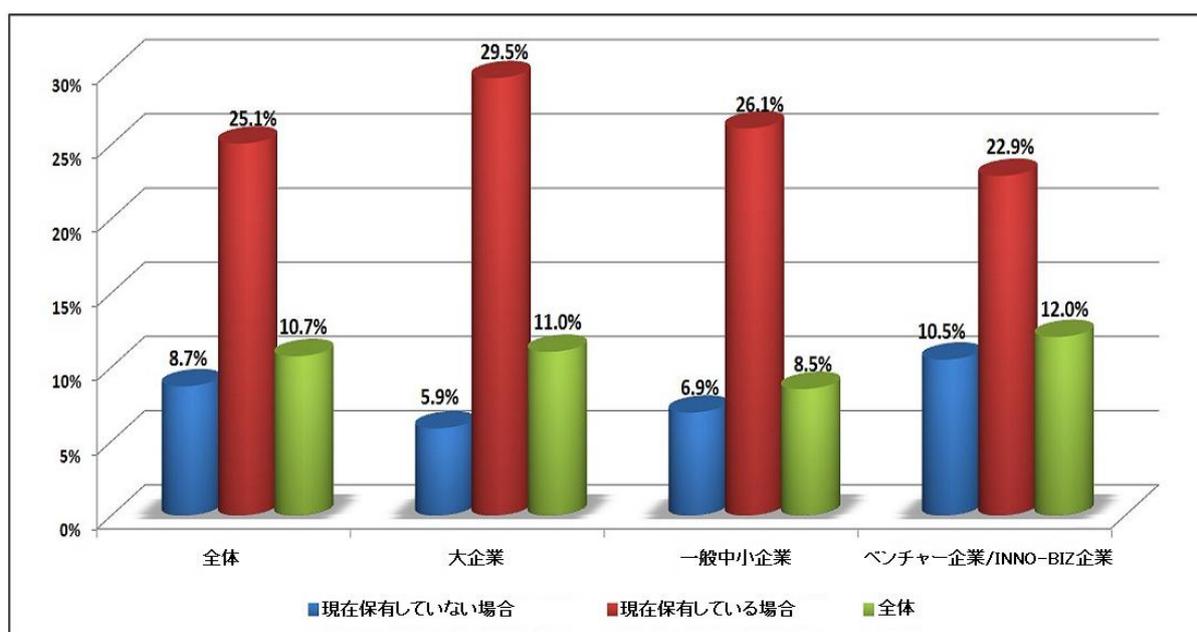
¹⁸ 企業の登録された特許権、デザイン権、商標権件数の総合

¹⁹ 10件未満出願企業0.19名、61件以上出願企業10.0名

²⁰ 10件未満出願企業1.47名、61件以上出願企業1.38名

知的財産担当人材を保有している場合、担当業務の内容は[図 2.4]のとおりである。知的財産担当人材が知的財産関連の紛争/訴訟、知的財産の活用、関連戦略の樹立などの業務を行っている企業の比率は産業財産権の出願/登録/維持などの業務を行っている比率に比べて極めて低いことがわかる。特に、大企業に比べて一般中小企業とベンチャー企業が保有している知的財産担当人材は高い専門性を要する知的財産戦略の樹立及び紛争/訴訟などの業務を行う上で相対的に限界があることを示している。

全体企業の 10.7%(12.1%)は今後知的財産担当人材を採用する計画があると回答している([図 2.5])。特に、現在知的財産担当人材を保有している企業の 25.1%(4.6%)が追加的に採用する計画があると答え、現在保有していない企業の 8.7%(7.5%)が新規採用計画があると回答している。



[図 2.5]知的財産専門担当人材の採用予定比率

企業類型別で見ると、ベンチャー企業のうち現在担当人材を保有している場合の 22.9%、保有していない場合の 10.5%が追加及び新規の採用計画があると回答している。一般中小企業と比べると追加採用計画の規模は相対的に低い数値ではあるものの、新規採用計画はより高くなっており、これはベンチャー企業の場合知的財産の管理に対する認識が最近になって高くなっていることを示唆している。また、現在知的財産

担当人材を保有していない場合の新規採用比率は大企業が 5.9%と最も低い。出願件数別で見ると、新規採用予定の比率は出願件数の多い企業が最も低く²¹、一方追加採用予定の比率は出願件数の多い企業が高いことがわかった。²²

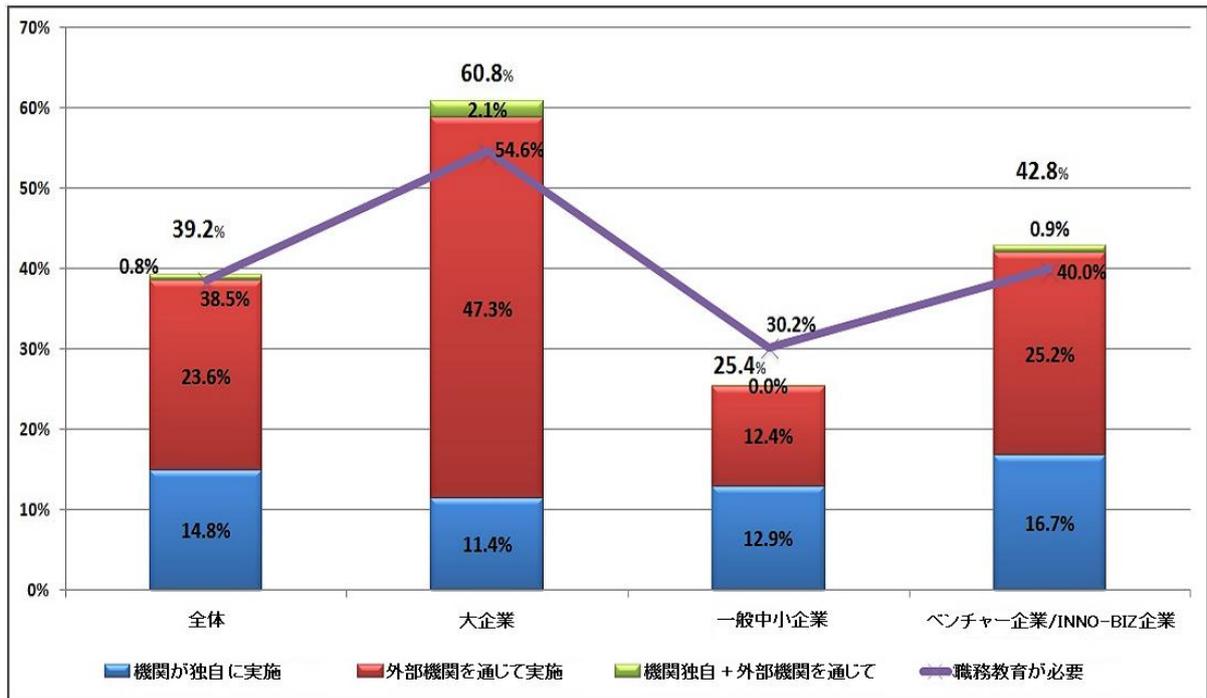
2.知的財産担当人材に対する職務教育及び人件費・教育費

全体の 39.2%(45.2%)に該当する企業は知的財産担当人材に対する職務教育を実施していることがわかる([図 2.6])。これは全体の 60.8%(54.8%)に該当する企業が知的財産担当人材向けの職務教育を如何なる形でも全く実施していないことを意味する。職務教育の形態別で見ると、独自に実施している場合が 14.8%、外部機関を通じて実施する場合が 23.6%となっている。

知的財産担当人材に対する職務教育の必要性は全体の 38.5%(42.2%)が必要またはとても必要であると認識していることがわかった。この比率は大企業が最も高い 54.6%、一般中小企業は最も低い 30.2%となっている。特に、一般中小企業は現在職務教育を実施している企業の比率は 25.4%で、職務教育が必要であると感じる企業の比率に比べて極めて低い水準である。これは特に一般中小企業の場合は職務教育の必要性は認識しているものの、あらゆる事情によって実施できない企業が多いという事実を物語っている。

²¹ 年平均10件未満出願企業の7.8%、年平均61件以上出願企業の4.9%

²² 年平均10件未満出願企業の2.3%、年平均61件以上出願企業の24.9%



[図 2.6]知的財産権担当人材に対する職務教育の状況及び必要性

職務教育の内容に関しては全体の 49.7%が特許制度と特許情報検索に関する職務教育が必要であると回答している(表 2.1)。その他に特許紛争及び訴訟と特許マップなど特許情報の分析方法に対する職務教育が必要であると回答した企業は各々34.7%と33.8%となっている。特に、特許ライセンス及び技術事業化関連の職務教育が必要であると答えた比率はベンチャー企業が 39.0%と大企業と一般中小企業より高いことがわかった。これはベンチャー企業の場合、自社が保有している技術を事業化またはライセンスする上で直面する困難が相対的に大きいことを意味する。

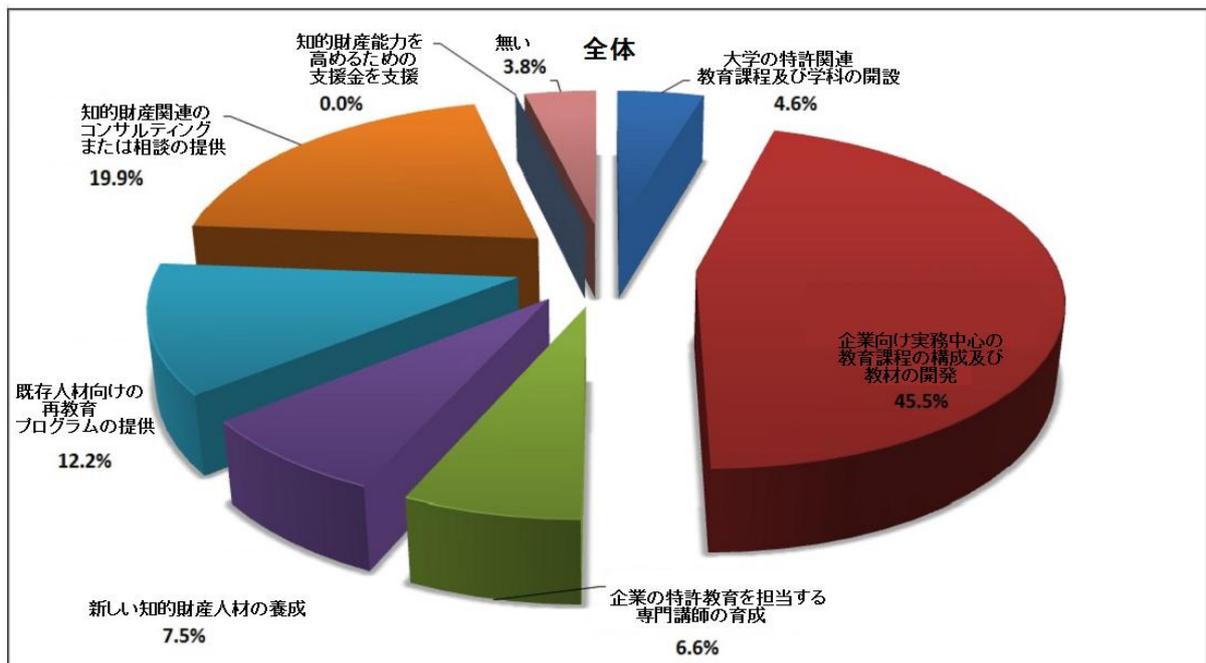
[表 2.1]職務教育の実施を希望する場合に扱うべき内容

	全体	大企業	一般中小企業	ベンチャー・INNO-BIZ
特許制度	49.7%	55.2%	52.4%	46.8%
特許明細書の作成法	21.4%	18.8%	18.2%	24.0%
特許情報の検索	49.7%	49.7%	48.6%	50.5%
特許紛争(訴訟)	34.7%	45.2%	32.2%	33.9%

特許情報の分析方法(特許マップ)	33.8%	34.1%	25.3%	39.1%
特許ライセンス(技術事業化)	36.7%	38.2%	32.4%	39.0%
海外特許出願及び訴訟	21.0%	24.2%	17.9%	22.1%
営業秘密の保護	23.4%	24.3%	21.6%	24.3%
その他	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%

注. 複数回答

最後に知的財産人材の能力強化のために必要な政府政策として、全体の 45.5% (44.9%)が実務中心の教育課程の構成及び教材の開発を挙げている([図 2.7])。また、知的財産関連のコンサルティングまたは相談の提供と既存人材向けの再教育プログラムの提供が最も必要であると回答した比率も各々19.9%と 12.2%となっている。知的財産能力を高めるために必要な政府政策に対する選好度は企業類型別に大きな差は見られない。但し、大企業の場合企業の特許教育を担当する専門講師の育成を挙げた比率が全体の 11.1%で、一般中小企業 2.6%、ベンチャー企業 8.0%より高い。



[図 2.7]知的財産人材の能力を高めるために必要な政府政策

知的財産担当者の人件費及び教育費は[表 2.2]のとおりである。2011 年の 1 年間企業が支出した知的財産担当者の人件費と教育費は各々1,896 万ウォン(2,352 万ウォン)と 281 万ウォン(379 万ウォン)²³となっている。企業類型別では大企業、中小企業、ベンチャー企業が支出した平均人件費及び教育費の合計は各々4,954 万ウォン、1,307 万ウォン、2,109 万ウォンとなっている。費用支出の絶対的な金額の他に企業が知的財産担当人材に投じる費用(人件費及び教育費)を企業の売上高と比べた結果²⁴、大企業は 0.03%、中小企業は 0.50%、ベンチャー企業は 2.03%となっており、ベンチャー企業の知的財産担当者に対する支出比率が高いことが確認できる。

[表 2.2]知的財産担当者の人件費及び教育費の状況

	人件費 ²⁵	教育費 ²⁶	合計
全体	1,896 万ウォン	281 万ウォン	2,178 万ウォン
大企業	4,032 万ウォン	922 万ウォン	4,954 万ウォン
一般中小企業	1,178 万ウォン	128 万ウォン	1,307 万ウォン
ベンチャー/INNO-BIZ 企業	1,873 万ウォン	237 万ウォン	2,109 万ウォン

3.知的財産サービスの活用状況

2011 年 1 年間外部の知的財産サービス²⁷を利用した企業は全体の 43.1%(47.4%)となっている([表 2.3])。企業類型別ではベンチャー企業の 48.6%(49.1%)が知的財産サービスを利用したと答えたが、これは大企業 47.1%(60.5%)、中小企業 32.6%(32.4%)より多少高い比率である。

²³ 企業が保有している知的財産担当者全員に対する総人件費及び教育費を意味する。

²⁴ (知的財産担当者の人件費及び教育費/売上高)*100で計算する。但し、無回答企業の場合は0と処理し、一部過小推定された可能性がある。

²⁵ 他の業務と兼職である場合、知的財産関連業務の比重を考慮して回答した結果である。

²⁶ 教育費は知的財産担当者向けの教育費と他従業員向け教育費の合計である。

²⁷ 知的財産サービスとは知的財産の創出、管理、活用、保護、取引などを支援する専門サービスで、情報調査及び分析、技術移転及び取引、IP翻訳、コンサルティングなどの事業を意味する。

[表 2.3]知的財産サービスの利用状況

区分		利用している	IP 情報調査/分析 ²⁸	技術移転/取引 ²⁹	IP 翻訳 ³⁰	IP コンサルティング/システム ³¹	合計
全体		43.1%	459 万ウォン	90 万ウォン	211 万ウォン	148 万ウォン	909 万ウォン
企業 類型 別	大企業	47.1%	1,258 万ウォン	49 万ウォン	812 万ウォン	300 万ウォン	2,419 万ウォン
	中小企業	32.6%	203 万ウォン	112 万ウォン	77 万ウォン	58 万ウォン	450 万ウォン
	ベンチャー 企業	48.6%	394 万ウォン	91 万ウォン	140 万ウォン	152 万ウォン	776 万ウォン
年出 願件 数別	10 件未満	42.1%	310 万ウォン	83 万ウォン	110 万ウォン	112 万ウォン	615 万ウォン
	11～20 件	48.1%	903 万ウォン	167 万ウォン	533 万ウォン	212 万ウォン	1,814 万ウォン
	21～60 件	49.2%	829 万ウォン	167 万ウォン	308 万ウォン	284 万ウォン	1,589 万ウォン
	61 件以上	70.1%	4,985 万ウォン	82 万ウォン	3,409 万ウォン	1,295 万ウォン	9,770 万ウォン

知的財産サービスを利用した企業の 2011 年平均支出額は IP 情報調査/分析が 459 万ウォン、IP 翻訳が 211 万ウォンと相対的に高い比重を占めている。知的財産サービスに対する平均支出額は企業類型別に大きな差を見せている。大企業の場合は IP 情報調査/分析と IP 翻訳関連支出額が各々 1,258 万ウォンと 812 万ウォンと相対的に高く、ベンチャー企業の場合は IP 情報調査/分析関連支出 394 万ウォン、IP コンサルティング/システム関連支出 152 万ウォンの順である。特筆すべき点はベンチャー企業の場合、技術移転/取引関連支出が 91 万ウォンで大企業より高いことである。これは必要な職

²⁸ 特許DB、調査分析、特許マップの作成、動向分析など

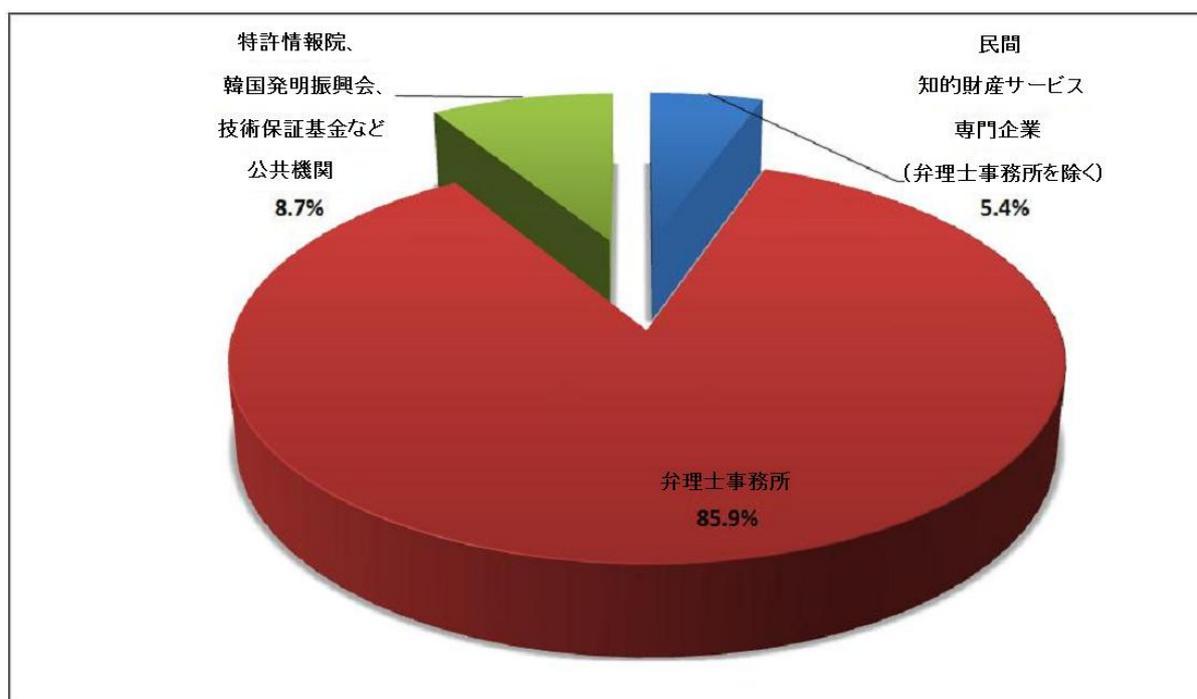
²⁹ 技術マーケティング、特許等級の評価、技術評価など

³⁰ 明細書の翻訳、仕様書の翻訳、翻訳出版など

³¹ IP経営コンサルティング、IP教育、IPシステムの構築など

務教育の内容として特許ライセンス及び技術事業化を挙げたベンチャー企業の比率が大企業及び中小企業より高かった前の結果と関連付けられる。すなわち、特許ライセンス業務を内部人材が行う上で専門性の限界を感じているため、該当業務関連の外部知的財産サービスに支出する金額が多いものと理解できる。

知的財産サービスを提供する機関類型別利用比重は弁理士事務所が 85.9%と最も大きな比重を占めている([図 2.8])。企業類型別では大企業 88.6%、一般中小企業 85.4%、ベンチャー企業 85.4%が弁理士事務所を利用していると回答している。特許情報院など公共機関は 8.7%、民間知的財産サービス専門企業は 5.4%となっている。特許情報院など公共機関の利用比重はベンチャー企業の場合 10.3%と他企業類型より相対的に高いことがわかった。また、ベンチャー企業は民間知的財産サービス専門企業を利用している比重が 4.3%と最低となっている。



[図 2.8]知的財産サービス提供機関別の利用比重

全体的に中小企業やベンチャー企業の場合、知的財産専門担当組織及び人材を確保するのが困難である場合が多く、それによって外部知的財産関連サービスや情報を利用する比率が高い。しかし、現在韓国の知的財産サービスは費用そのものが高価である上に市場が零細であるためサービス提供機関の偏差が激しく、不安定な面が多い。

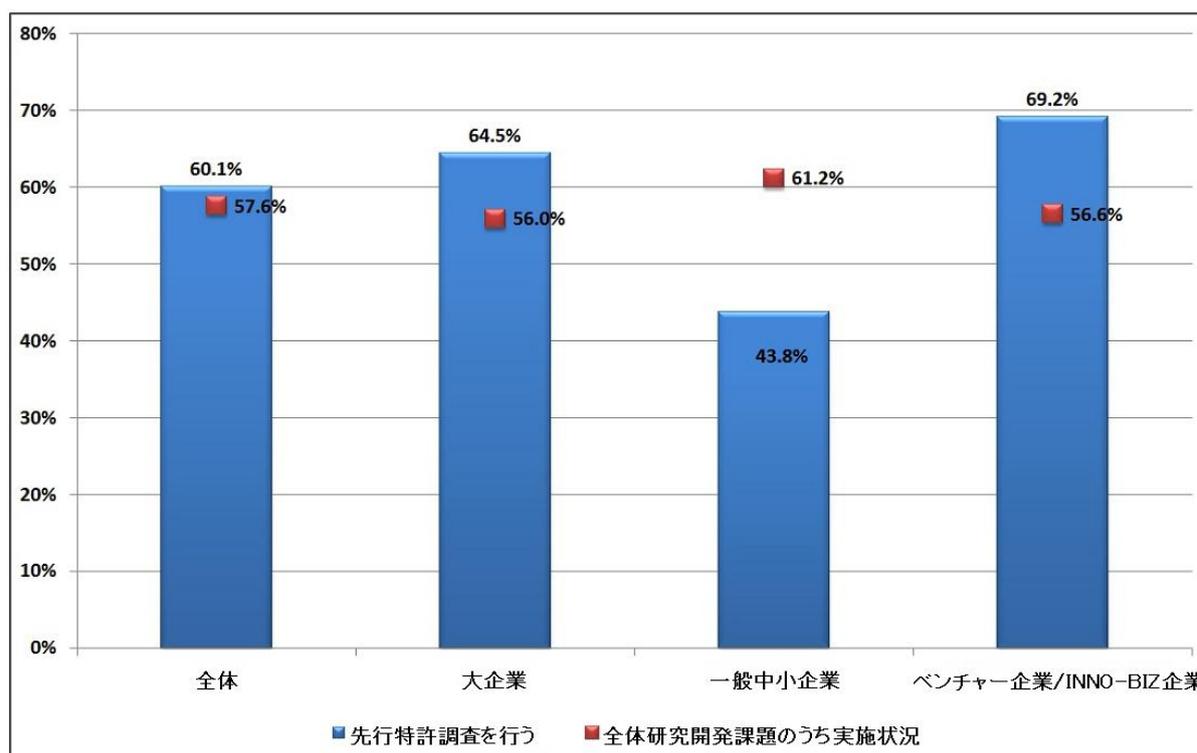
したがって、中小企業の知的財産サービス活用に向けた支援を政策的に実行する一方、知的財産専門教育を拡大し、持続的によりレベルの高い教育が施行できるよう支援しなければならない。さらに、多様かつ膨大な特許情報を提供し、多角的な側面からアクセス可能な特許情報システムを構築することでインフラが強化できるよう、政策的に支援する必要がある。

第2節 知的財産の創出

1.研究開発過程における特許情報の活用

研究開発の企画段階で先行特許調査³²など特許情報を調査する企業の比率は 60.1% (70.0%)となっている([図 2.9])。この企業らは全体研究開発課題の 57.6%(57.0%)に対して先行特許調査を行っていることがわかった。

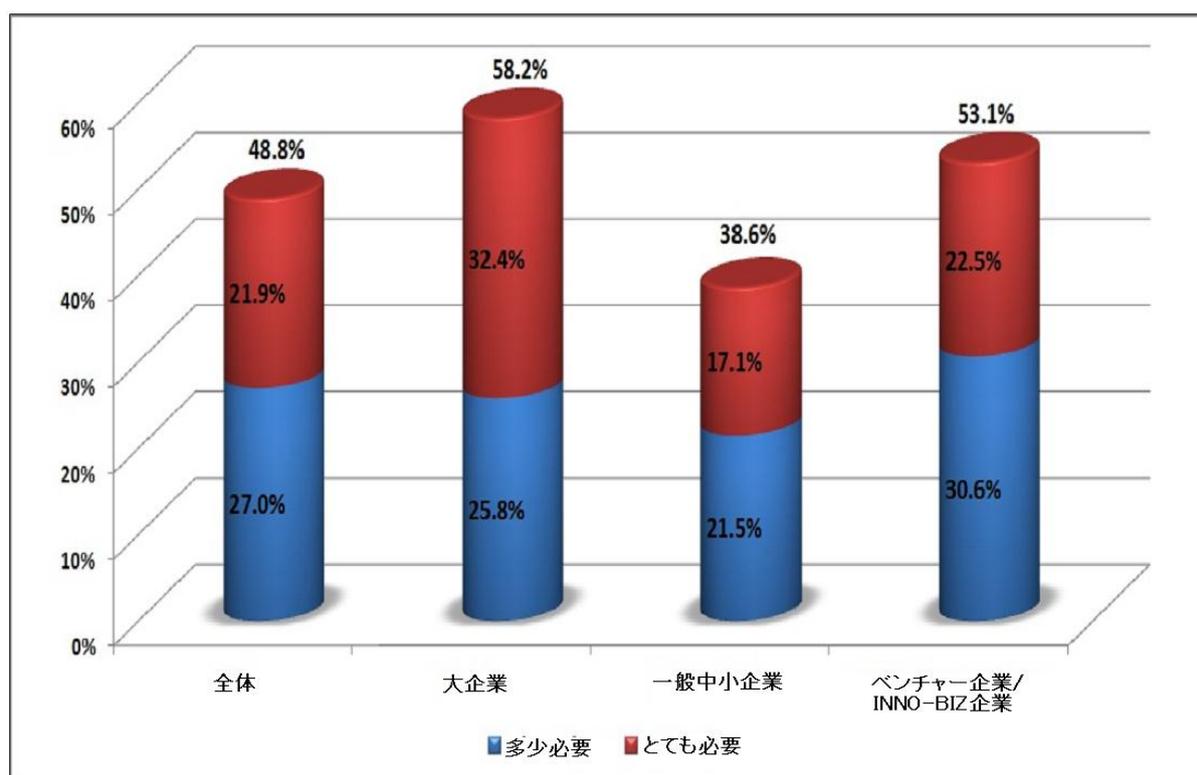
企業類型別では大企業 64.5%(75.0%)、一般中小企業 43.8%(59.8%)、ベンチャー企業 69.2%(72.2%)が先行特許調査を行っていると答えている。すなわち、ベンチャー企業が大企業より先行特許調査をより活発に行っているといえる。全体研究開発課題のうち先行特許調査を行っている比率は企業類型別に大きな差はない。



[図 2.9]先行特許情報調査の実施状況

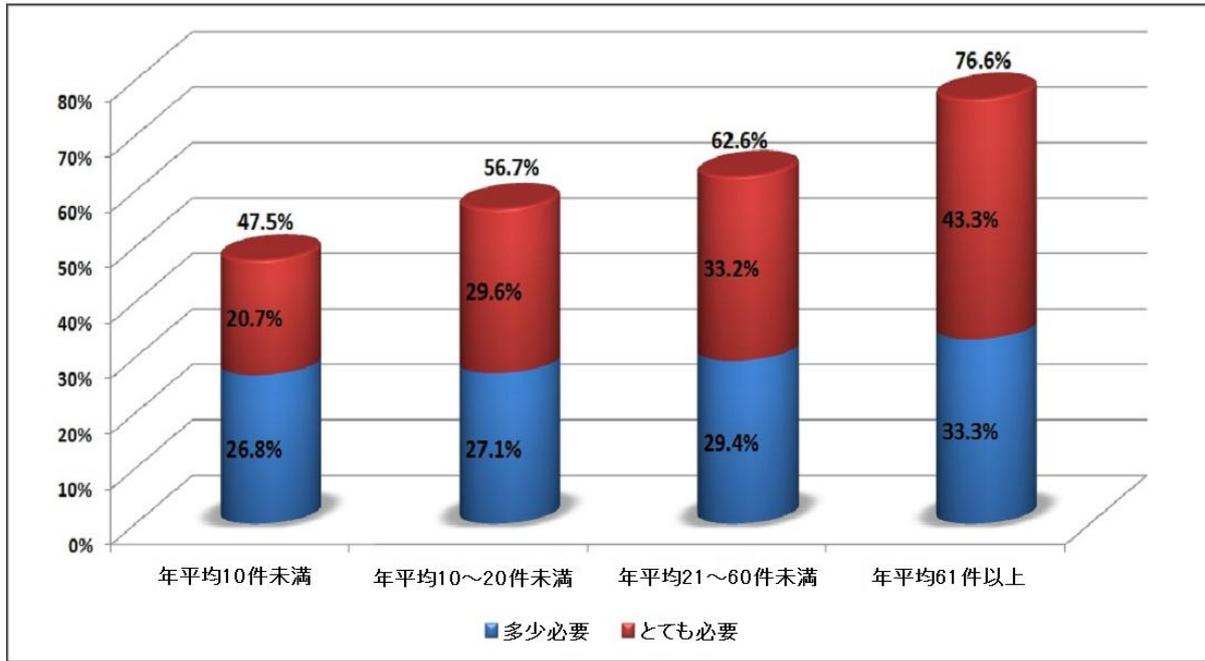
³² 先行特許調査とは、新技術の開発などのための研究開発(R&D)活動に先立って開発しようとする技術に対する先行技術または該当技術と同一もしくは類似した特許が存在しているかどうかなどを調査するものである。

知的財産担当者が認識している先行特許調査の必要性に対しては全体の 48.8% (54.7%)が必要またはとても必要であると回答している([図 2.10])。逆にいえば、全体の約 50%が先行特許調査の必要性を全く認識していないものと解釈できる。企業類型別では一般中小企業が大企業及びベンチャー企業より先行特許調査が重要であると認識している比率が低いことがわかる。



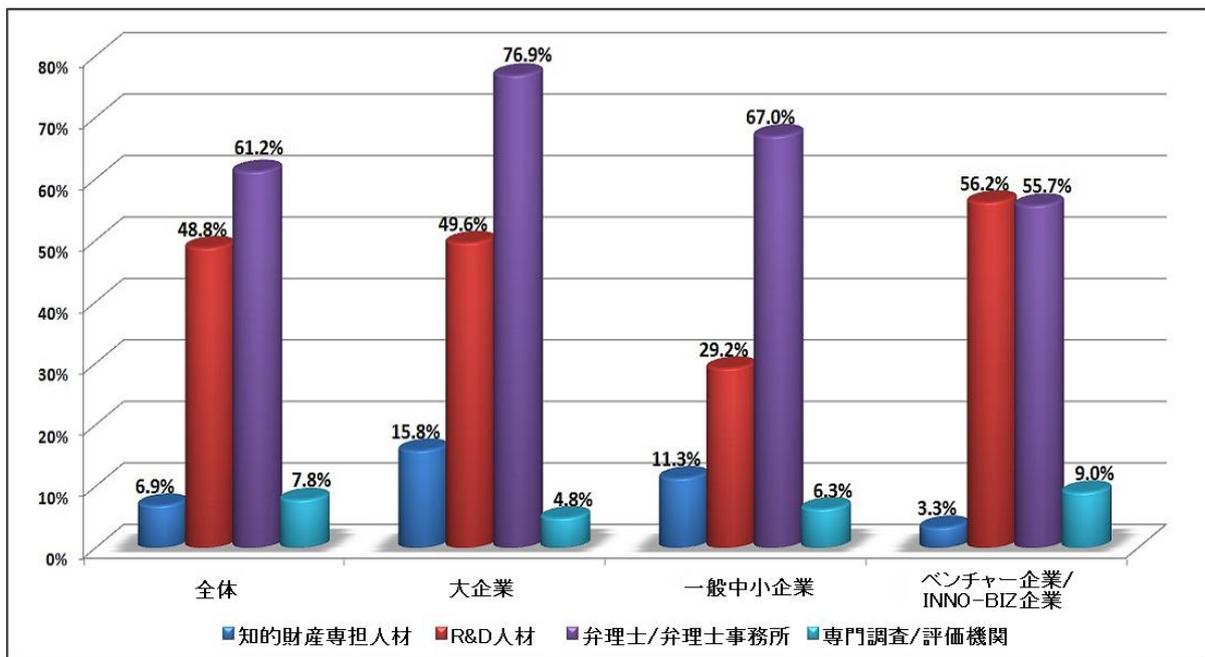
[図 2.10]先行特許調査の必要性

出願件数別では([図 2.11])、多出願企業であるほど先行特許調査がとても必要であると答えた比率が増加している。企業が認識している先行特許調査の必要性は業種別に大きな差を示している。業種別では、化学産業に属している企業のうち先行特許調査がとても必要と認識している比率は 68.4%である一方、卸/小売業に属している企業はわずか 31.3%に過ぎないことがわかった。



[図 2.11]出願件数別の先行特許調査必要性

先行特許調査を行っている場合の 61.2%(65.8%)が該当業務を弁理士に依頼していることがわかった([図 2.12])。また、研究開発人材が直接行ったり、知的財産専門人材が担当する場合も各々48.8%(46.8%)と 6.9%(8.1%)となっている。



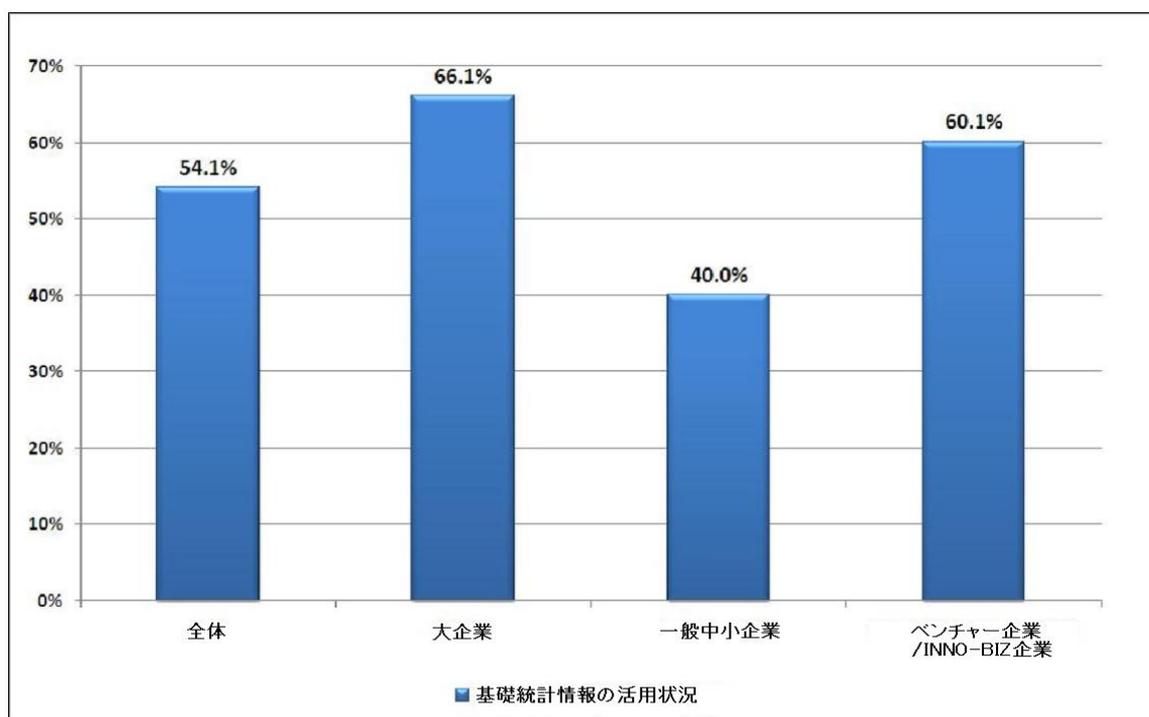
[図 2.12]先行特許調査を行う場合の遂行人材

注. 複数回答

企業類型別では、知的財産専門担当人材が該当業務を行う比率が大企業 15.8%と他の企業類型より高い。また、多出願企業であるほど知的財産専門担当人材が該当業務を行う比率が高い。³³業種別では、化学産業のように技術的な複雑性の高い産業に属している企業の場合、研究開発人材が直接先行技術調査を行う比率が高い。³⁴

知的財産統計など基礎統計情報を活用している比率は全体の 54.1%(63.0%)となっている([図 2.13])。機関類型別では、大企業の活用比率が 66.1%と最も高く、ベンチャー企業 60.1%、一般中小企業 40.0%と続いている。

主に活用している統計指標に関する調査項目では「単純検索」を通じて利用する場合が回答者の 60.9%、主に「先行技術件数」を活用している比率が 33.1%となっており、企業類型による違いは見当たらない。より頻繁に公表してほしい統計指標としては「産業部門別出願件数」を求める比率が 7.1%と最も多く、「登録件数」及び「年度別出願件数」に対する比率が各々2.3%を占めている。



[図 2.13]知的財産基礎統計の活用状況

³³ 年平均61件以上出願企業の52.8%

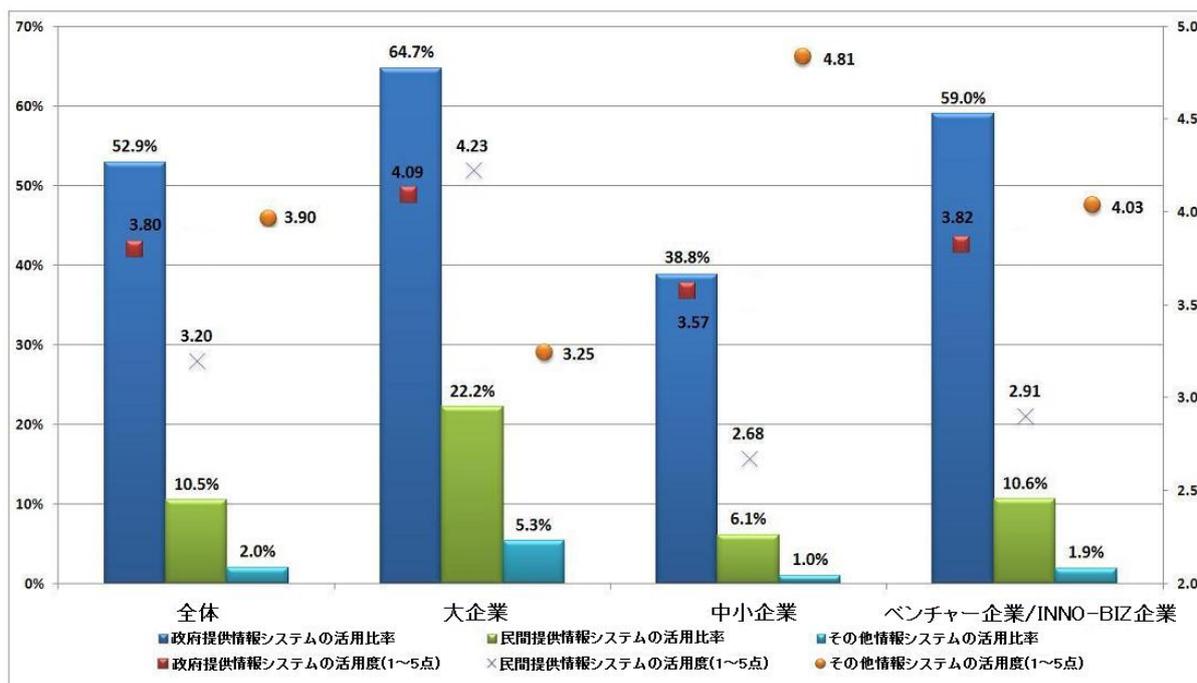
³⁴ 62.5%

政府または民間が提供する知的財産情報システムの活用度を見ると、まず政府が提供する知的財産情報システムを活用していると答えた比率は 52.9%(61.8%)となっている([図 2.14])。活用している企業の中で活用度が高いと答えた比率は 32.3%(40.4%)、平均活用度(5点尺度)は 3.80点(3.89点)となっている。企業類型では、大企業の 64.7%(77.1%)、ベンチャー企業の 59.0%(64.9%)が情報システムを活用していると答え、中小企業の 38.8%(41.5%)に比べて高いことがわかる。活用度が高いと答えた比率もまた大企業、ベンチャー企業、中小企業の順となっており、平均活用度もまた同順となっている。³⁵

民間が提供する知的財産情報システムを活用していると答えた比率は 10.5%(15.1%)となっている([図 2.14])。活用している企業のうち活用度が高いと答えた比率は 4.1%(6.4%)で、平均活用度は 3.20点(3.28点)となっている。企業類型別では各々大企業 22.2%(32.8%)、ベンチャー企業 10.6%(12.4%)、中小企業 6.1%(8.9%)と続いている。活用度が高いと答えた比率及び平均活用度も同順³⁶となっている。その他情報システムの場合は 2.0%(2.7%)が活用していると答え、大企業 5.3%(8.9%)、ベンチャー企業 1.9%(1.8%)、中小企業 1.0%(0.5%)となっている。

³⁵ 活用度が高いと答えた大企業は48.0%(57.7%)、ベンチャー企業は36.6%(41.6%)、中小企業の場合19.7%(23.5%)であり、平均活用度は各々4.09点(4.17点)、3.82点(3.87点)、3.57点(3.58点)となっている。

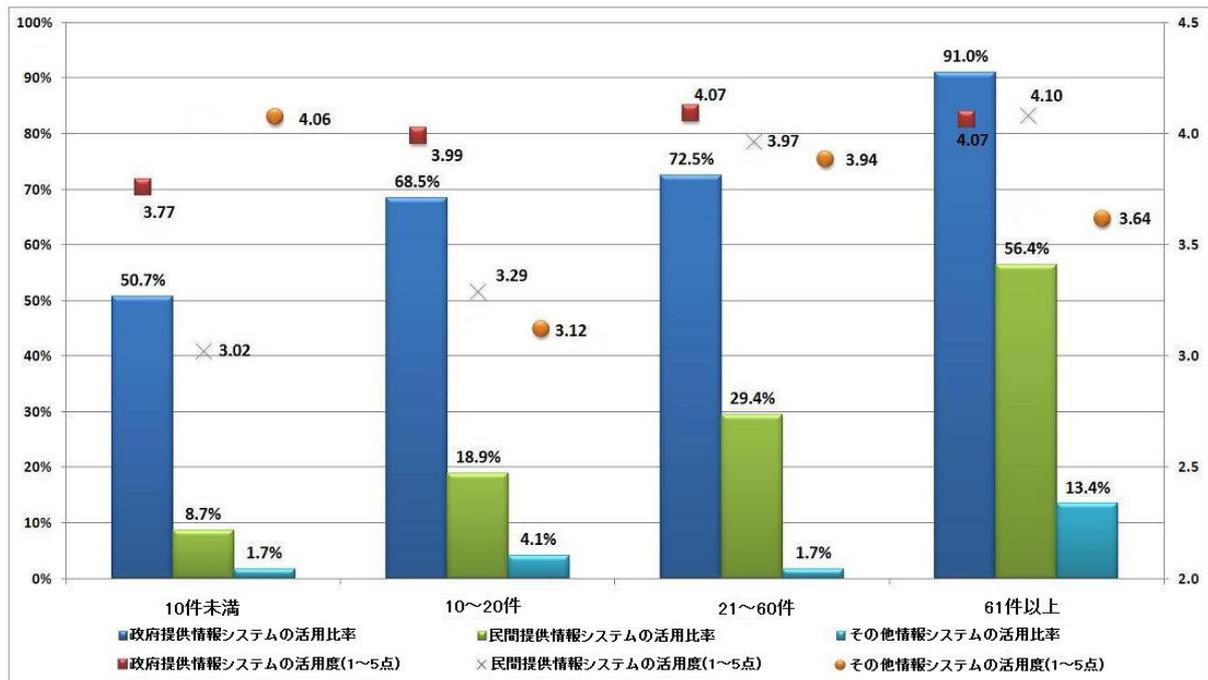
³⁶ 活用度が高いと答えた大企業は17.3%(22.7%)、ベンチャー企業は2.7%(3.2%)、中小企業の場合1.6%(2.9%)となっており、平均活用度は各々4.23点(4.10点)、2.91点(2.85点)、2.68点(2.63点)となっている。



【図 2.14】企業類型別の知的財産情報システムの活用

出願規模別に政府が提供する知的財産情報システムの活用比率を見ると、年平均 10 件未満企業の場合 50.7%(55.1%)が活用していると答え、10~20 件出願企業が 68.5% (73.6%)、21~60 件出願企業が 72.6%(65.8%)、61 件以上多出願企業の場合 91.0% (90.7%)となっている(【図 2.15】)。出願規模が大きいほど活用比率が増加し、知的財産が多いほど情報システムの活用比率が高いことがわかる。主に活用している政府提供情報システムとしては「KIPRIS」が 96.6%と最も高く、「特許路」が 3.0%、「KIPO」が 0.9 となっている。

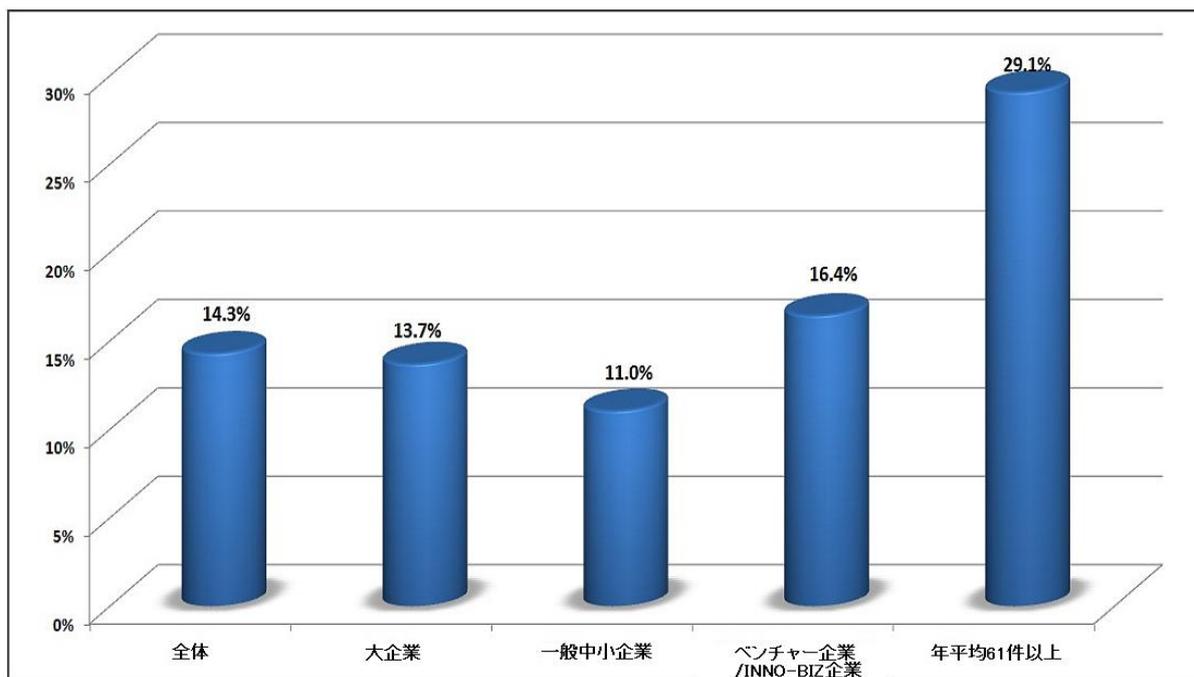
民間が提供する知的財産情報システムの活用比率もまた出願規模が大きくなるにつれ、各々活用比率が 8.7%(10.1%)、18.9%(19.4%)、29.4%(27.2%)、56.4%(40.2%)と増加している。主に活用している民間提供情報システムの場合、「WIPS」が 93.7%と最も高く、「FOCUST」、「医薬品特許インフォマティクス」が各々2.3%、1.5%となっている。また、その他情報システムとして「世界国家別特許庁」、「NDSL」などを活用していることがわかった。



[図 2.15]出願規模別の知的財産情報システムの活用

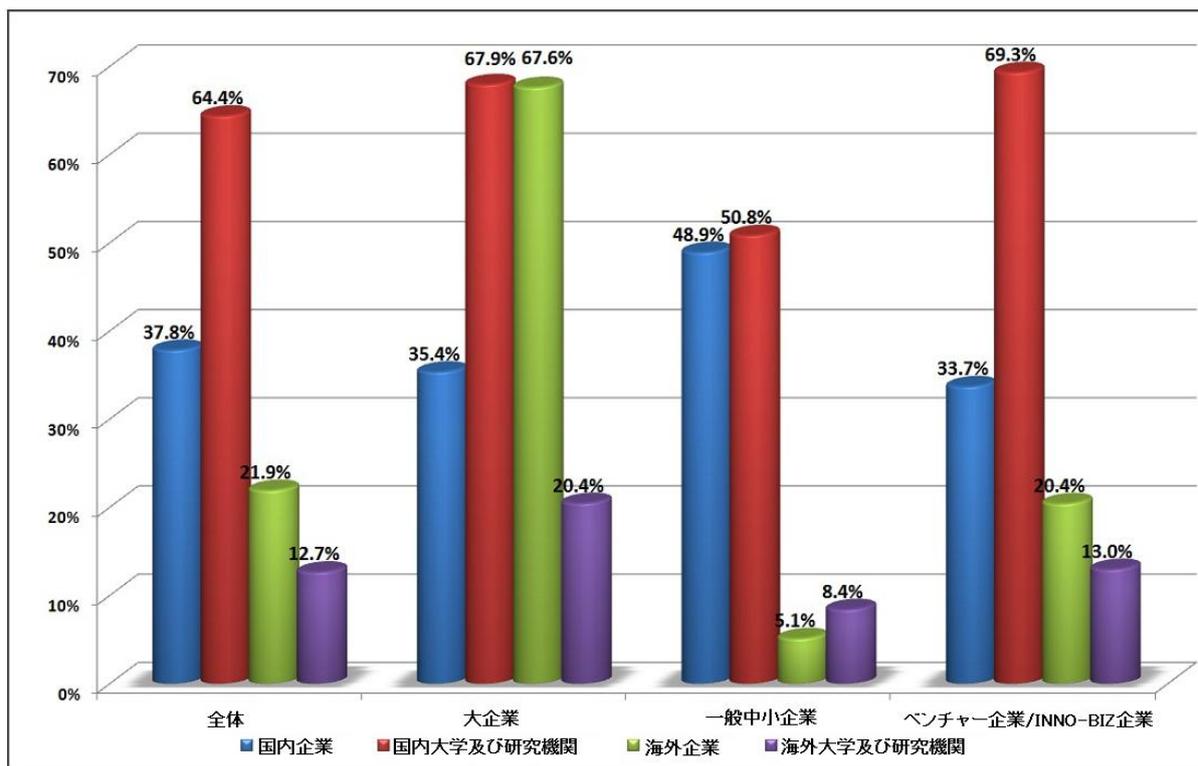
2.外部から導入した知的財産の実績及び今後の計画

外部から知的財産を導入すると回答した企業は全体の 14.3%(16.7%)となっている([図 2.16])。これは縮小すると答えた比率の 4.5%(4.3%)より高い数値である。企業類型では、ベンチャー企業が導入を拡大すると答えた比率が 16.4%(17.9%)で大企業 13.7%(15.2%)より高い。知的財産の導入を拡大すると答えた企業の比率は出願件数の多い多出願企業であるほど高いことがわかった。業種別では化学産業に属している企業の 29.4%が知的財産の導入を拡大すると答え、最も高い数値となっている。



[図 2.16]知的財産の導入を拡大する予定である企業の比率

知的財産導入に向けた投資拡大を計画している場合、国内大学及び公共研究機関からの知的財産導入を拡大すると答えた企業が 64.4%(63.4%)で最も多く、国内企業からの知的財産導入を拡大すると答えた企業の比率は 37.8%(39.9%)となっている([図 2.17])。また、海外企業からの知的財産導入を拡大する計画を立てている企業の比率も 21.9%(同一)となっている。



[図 2.17]知的財産導入に向けた投資拡大の方向

注. 複数回答

企業類型別では、知的財産の導入拡大を計画している大企業の場合国内大学及び研究機関から知的財産を導入すると回答した比率が 67.9%、海外企業から知的財産を導入すると答えた比率が 67.6%となっており、国内企業または海外大学及び研究機関から知的財産を導入しようとする比率に比べて相対的に高い。また、ベンチャー企業は国内大学及び研究機関から知的財産の導入を拡大すると答えた比率が 69.3%となっており、他のタイプの導入計画より相対的に高い。すなわち、大企業は国内及び研究機関だけでなく海外企業からの知的財産導入も拡大しようとしているのに対し、ベンチャー企業は国内研究機関からの導入をベースとしていることがわかる。一般中小企業の場合は国内企業からの知的財産導入比率が 48.9%で他の企業類型(大企業の場合 35.4%、ベンチャー企業の場合 33.7%)に比べて相対的に高くなっている。

最近 3 年間外部から知的財産を導入した企業の比率は[表 2.4]のとおりである。国内その他企業から知的財産を導入した企業の比率は 6.1%(6.4%)で最も高く、その他に出捐(研)など公共研究機関 4.2%(4.6%)、国内大学 3.6%(5.1%)と続いている。

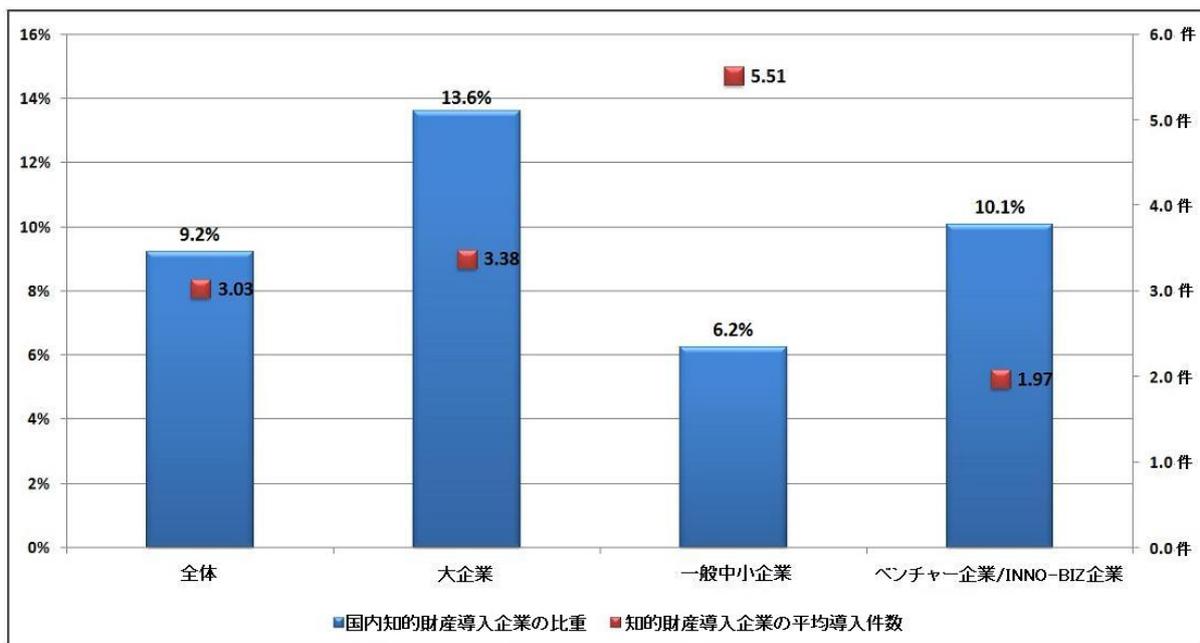
企業類型別では大企業の場合国内需要/供給企業からの導入比率が 6.1%と高いことに対して、ベンチャー企業は国内その他企業(6.3%)及び公共研究機関(4.6%)から知的財産を導入した比率が高いことがわかった。

[表 2.4]最近 3 年間外部から知的財産を導入した企業の比率

	企業全体	大企業	一般中小企業	ベンチャー・ INNO-BIZ
国内グループ系列会社	0.7%	3.9%	0.1%	0.4%
国内需要(納品)/供給(下請)企業	2.3%	6.1%	0.2%	2.7%
国内その他企業	6.1%	3.3%	6.9%	6.3%
国内大学	3.6%	4.4%	2.5%	4.1%
出捐(研)など公共研究機関	4.2%	4.9%	3.2%	4.6%
海外企業	2.3%	5.6%	2.0%	1.7%
海外大学・研究所	0.4%	1.4%	0.7%	0.1%

一方、2011年の1年間国内から知的財産を導入した企業は全体の9.2%(11.5%)を占めている([図 2.18])。海外から導入した比率も1.0%(同一)となっている。企業類型別では大企業の13.6%(14.9%)、一般中小企業の6.2%(9.7%)、ベンチャー企業の10.1%(11.2%)が国内から知的財産を導入している。業種別では電気/電子産業に属している企業の中で国内から知的財産を導入した比率が15.0%で最も高く、その他製造業、化学産業が各々13.7%、11.7%と続いている。

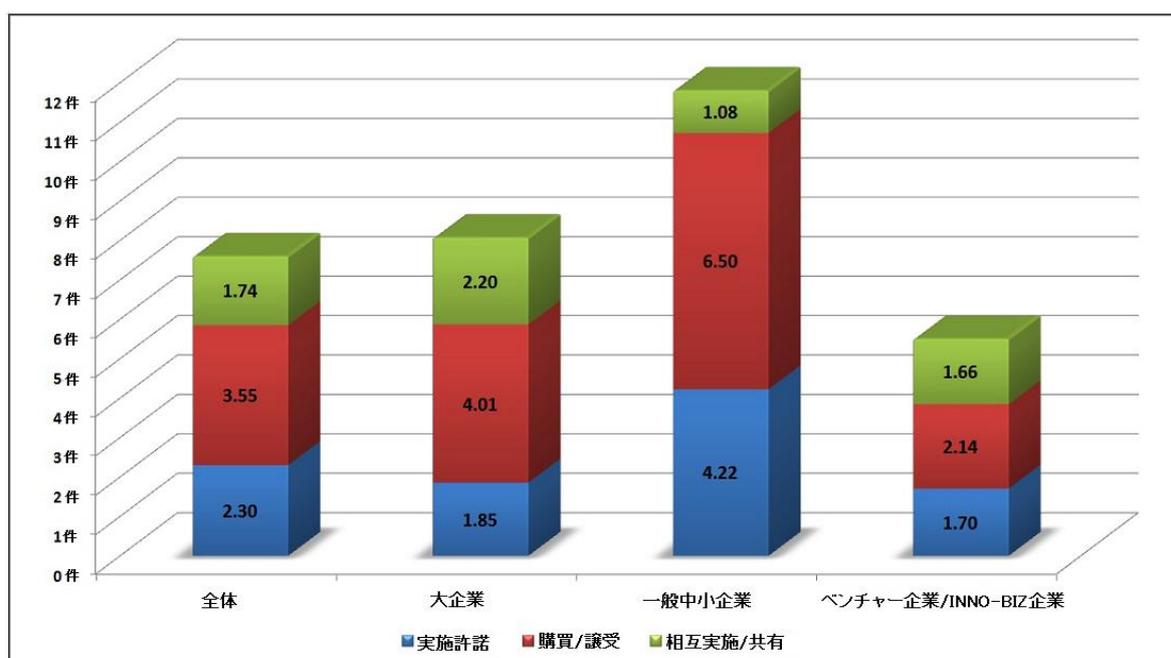
また、国内から知的財産を導入した企業の平均導入件数は3.03件(2.87件)、全体企業の平均は0.28件(0.33件)となっている([図 2.18])。企業類型別では大企業、中小企業、ベンチャー企業の平均知的財産導入件数は各々3.38件(3.88件)、5.51件(3.64件)、1.97件(2.26件)となっている。業種別では鉄鋼/金属に属している企業の知的財産導入企業平均導入件数が11.75件(同一)で最も高い。



[図 2.18]国内知的財産導入企業の比率及び平均導入件数

注. 件数は知的財産を導入した企業の平均である。

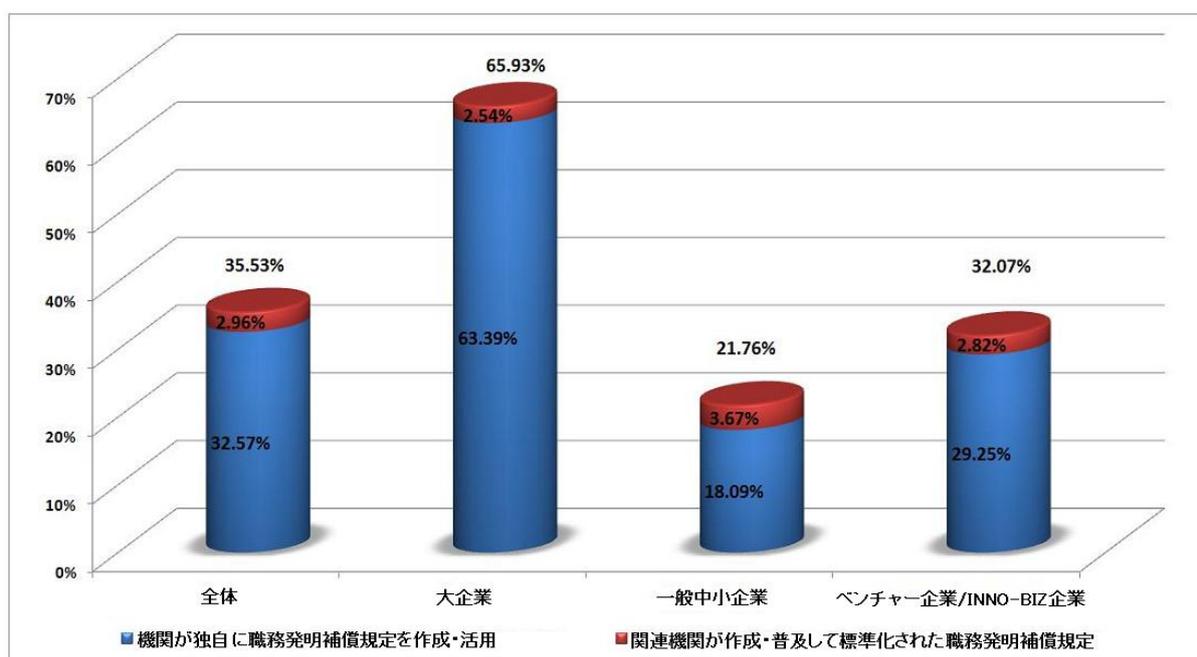
導入した知的財産を類型では、平均的に 3.55 件の知的財産を購買/譲受の形で導入しており、企業類型に関係なく最も高いことがわかる([図 2.19])。また、実施許諾、相互実施/共有の形で導入した件数も平均 2.30、1.74 件となっている。



[図 2.19]知的財産を導入した企業の類型別導入件数

3.職務発明補償

職務発明補償規定³⁷を保有・活用している企業の比率は 35.5%(既存母集団木ギューンによる標本調査の結果 43.8%)³⁸となっている([図 2.20])。これを細分化すると、機関が独自に職務発明補償規定を作成して活用している比率が 32.6%(40.8%)となっており、特許庁など関連機関が作成・普及・標準化された職務発明補償規定を保有・活用している比率は 3.0%(同一)となっている。



[図 2.20]職務発明補償規定の保有及び活用状況

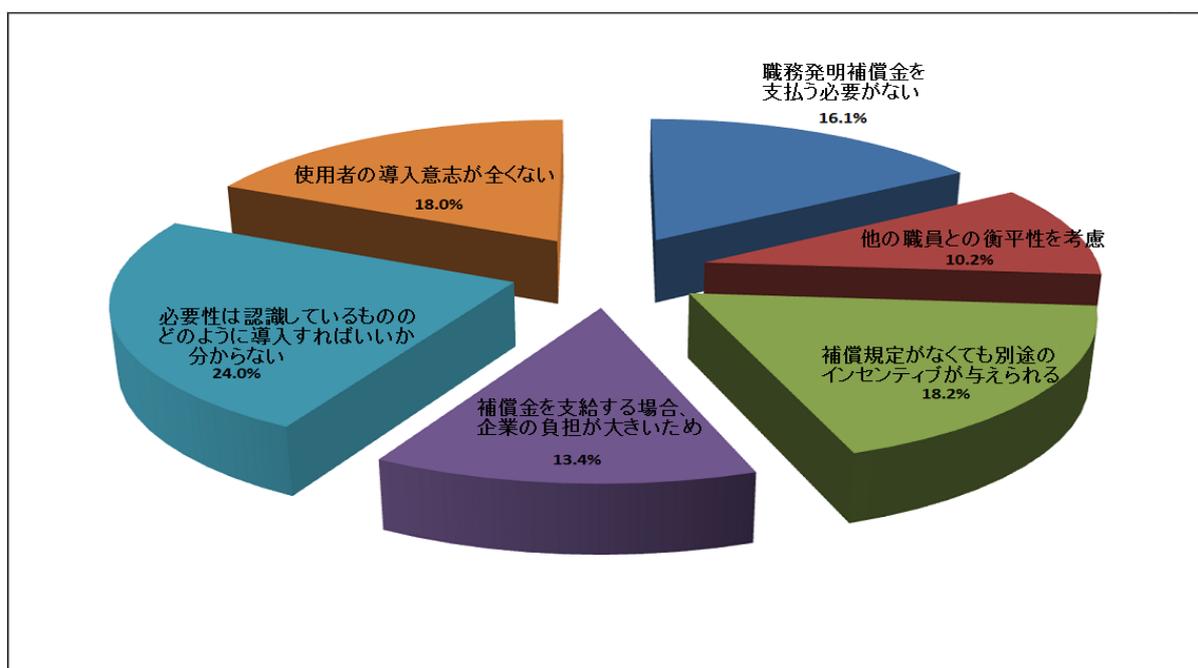
注. 2010年度既存母集団の推定値である。

企業類型別では大企業の 65.9%(72.9%)が職務発明補償規定を保有/活用しており、最も高く、続いて一般中小企業の 21.8%(26.0%)、ベンチャー企業の 32.1%(35.1%)が職務発明補償規定を保有・活用していることがわかった。

³⁷ 研究者が職務上行った発明に対して会社がその発明に対する特許権を承継し、特許取得と事業化を通じて発生した利益を研究者に補償することを指す。職務発明補償規定の保有状況は特許、実用新案保有企業をその調査対象にしたほうがより合理的であるため、既存母集団推定値(基準年度に特許、実用新案2件以上出願企業)を提示している。

³⁸ 本章では既存母集団基準による標本調査の結果を括弧の中に表示している。

補償規定を保有していない理由は必要性は認識しているもののどのように導入すればいいか分からないと回答した比率が 24.0%(24.4%)、補償規定がなくても別途のインセンティブが与えられるためと答えた比率が 18.2%(18.7%)を占めている([図 2.21])。企業類型別では、必要性は認識しているもののどのように導入すればいいか分からないと答えた比率は中小企業が 26.5%(29.1%)で大企業 20.2%(21.0%)やベンチャー企業 23.6%(23.4%)に比べて高い。



[図 2.21]職務発明補償規定を保有していない場合、その主な理由

注. 2010年度既存母集団の推定値である。

職務発明補償の類型別実施状況を見ると次の[表 2.5]のとおりである。国内特許登録補償、国内特許出願補償、海外特許登録補償を実施している比率が各々 91.0%、79.8%、67.3%と高いことがわかる。企業類型別では大企業と中小企業は国内特許登録補償（93.2%、90.2%）、国内特許出願補償(82.3%、81.0%)、海外特許登録補償(72.1%、68.4%)の順となっている。

[表 2.5]職務発明補償類型別の実施比率

	全体	大企業	一般中小企業	ベンチャー/INNO-BIZ 企業
発明提案(発明届出)補償	49.8%	34.3%	65.0%	54.9%
出願留保	29.2%	30.6%	40.8%	25.6%
国内特許出願	79.8%	82.3%	81.0%	78.1%
国内特許登録	91.0%	93.2%	90.2%	90.0%
海外特許出願	57.3%	61.7%	57.9%	54.7%
海外特許登録	67.3%	72.1%	68.4%	64.3%
その他産業財産権の国内登録	52.8%	54.9%	52.8%	51.6%
その他産業財産権の海外登録	43.5%	44.7%	49.0%	41.5%
自社実施	40.7%	43.7%	39.3%	39.3%
他社実施	23.7%	24.6%	21.6%	23.8%
処分	26.1%	28.9%	25.8%	24.6%

注. 2010年度既存母集団推定値である。

職務発明に対して金銭的な補償を実施する場合補償金の水準を見ると、国内特許登録補償平均 57 万ウォン、国内特許出願補償平均 29 万ウォン、海外特許登録補償平均 68 万ウォンとなっている。2011 年の 1 年間発明届出/出願/登録に対して金銭的補償を支払った企業は平均 2,031 万ウォンを使っていることが分かった。企業類型別では大企業が平均 4,418 万ウォン、一般中小企業平均 1,660 万ウォン、ベンチャー企業平均 834 万ウォンとなっている。実施/処分補償の場合、企業全体は平均 75 万ウォンを支出し、企業類型別では大企業平均 195 万ウォン、一般中小企業 61 万ウォン、ベンチャー企業平均 10 万ウォンを支出している。

職務発明補償と関連する制度の効果と関連し、職務発明に対する補償実施または補償水準の拡大が機関内の発明件数及び品質向上と技術流出防止に効果的であると答えた比率が各々 51.0%と 38.0%を占めている。

4.効果的な知的財産創出のために必要な政策支援

効果的に知的財産を創出するために中小企業特許コンサルティング事業の拡大など中小企業の知的財産権創出支援が必要であると認識している企業の比重が 56.9%と最も高く、特許情報活用拡散事業の拡大など先行特許調査と特許情報の活用支援が必要であると認識している企業は 56.6%、税制メリット付与及び関連規定の整備支援が求められると認識している企業が 55.3%となっている([表 2.6])。その他に研究者などを対象とする知的財産権関連教育支援、多様な技術分野に対する特許マップ構築支援に対する必要性が提起された。

[表 2.6]効果的な知的財産創出のための政策支援の必要性

	全体	大企業	一般中 小企業	ベンチャー /INNO-BIZ 企業
税制メリット付与及び関連規定の整備支援	55.3%	60.8%	47.8%	58.8%
特許情報活用拡散事業の拡大など 先行特許調査と特許情報の活用支援	56.6%	59.6%	51.2%	59.2%
中小企業特許コンサルティング事業の拡大な ど中小企業の知的財産権創出支援	56.9%	55.8%	54.0%	58.9%
多様な技術分野に対する特許マップ構築支援	49.6%	50.2%	45.1%	52.3%
研究者向け知的財産権関連教育の支援	53.4%	57.1%	45.7%	57.2%

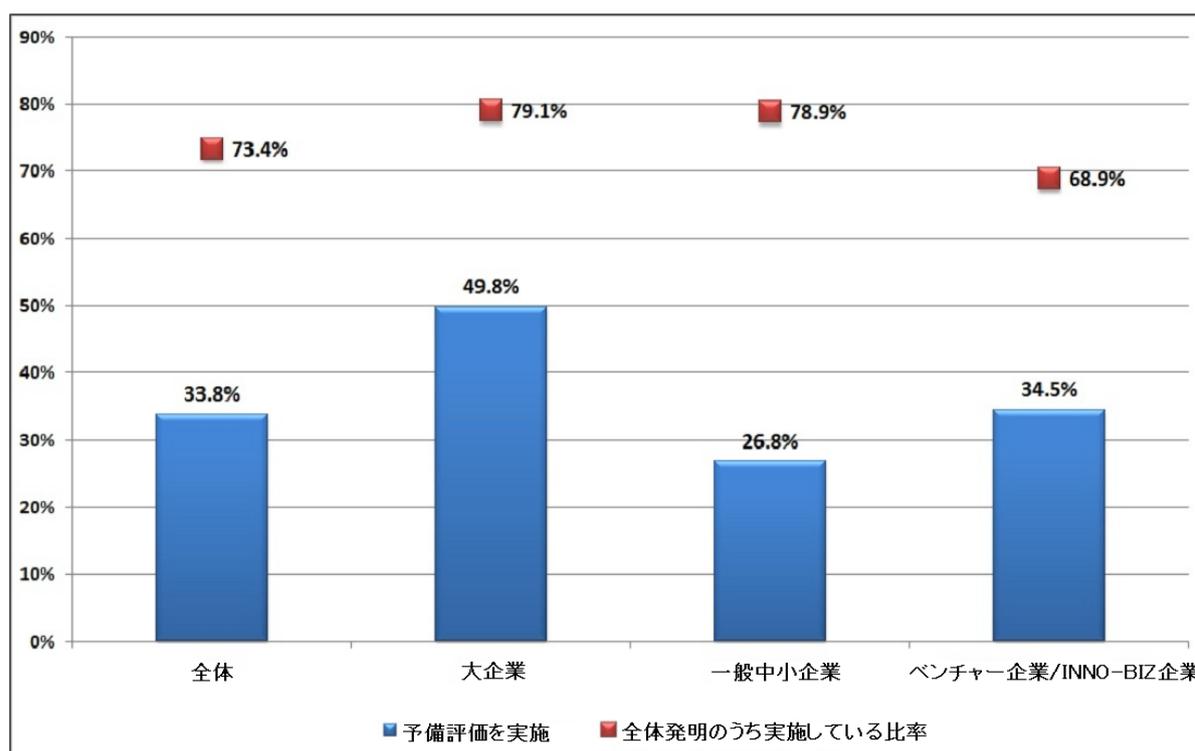
注. (%)は 5 点尺度(1：必要性が最も低い、5：必要性が最も高い)で[(4 点と 5 点と答えた企業数)/(総回答機関数)]×100(%)

第3節 知的財産の保護

1. 予備評価の実施状況及び方法

産業財産権の出願などに先立ち予備評価³⁹を行っている企業の比率は 33.8%(39.7%) となっており、平均的に全体発明件数の 73.4%(73.7%)に対して予備評価を行っているいると答えている([図 2.22])。

企業類型別では、大企業の 49.8%(57.6%)が予備評価を実施しており、発明届出件数のうち予備評価を実施する比率は 79.1%(79.2%)となっている。また、予備評価を行う企業の比率と全体発明件数のうち予備評価を行う比率、いずれも年平均出願件数が多いほど増加していること⁴⁰がわかった。

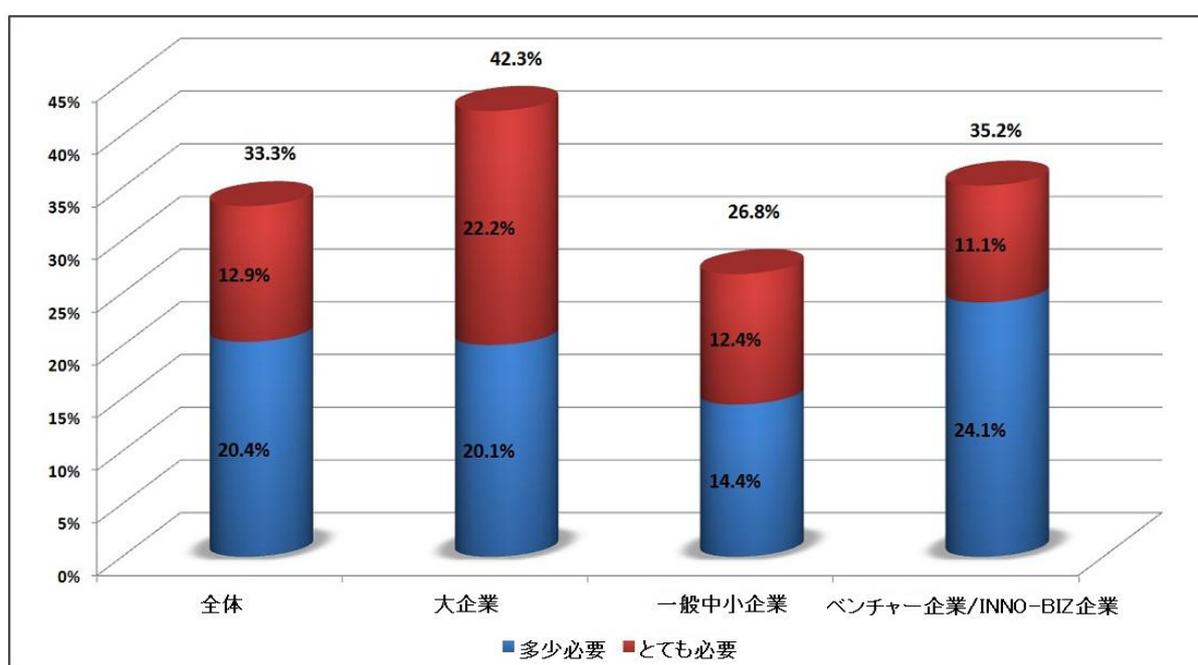


[図 2.22]産業財産権出願前の社内予備評価の実施状況

³⁹ 「予備評価」とは提出された発明届出書に対して職務発明委員会などを通じて発明の評価、承継状況、出願状況、審査請求状況などを決定することを意味する。

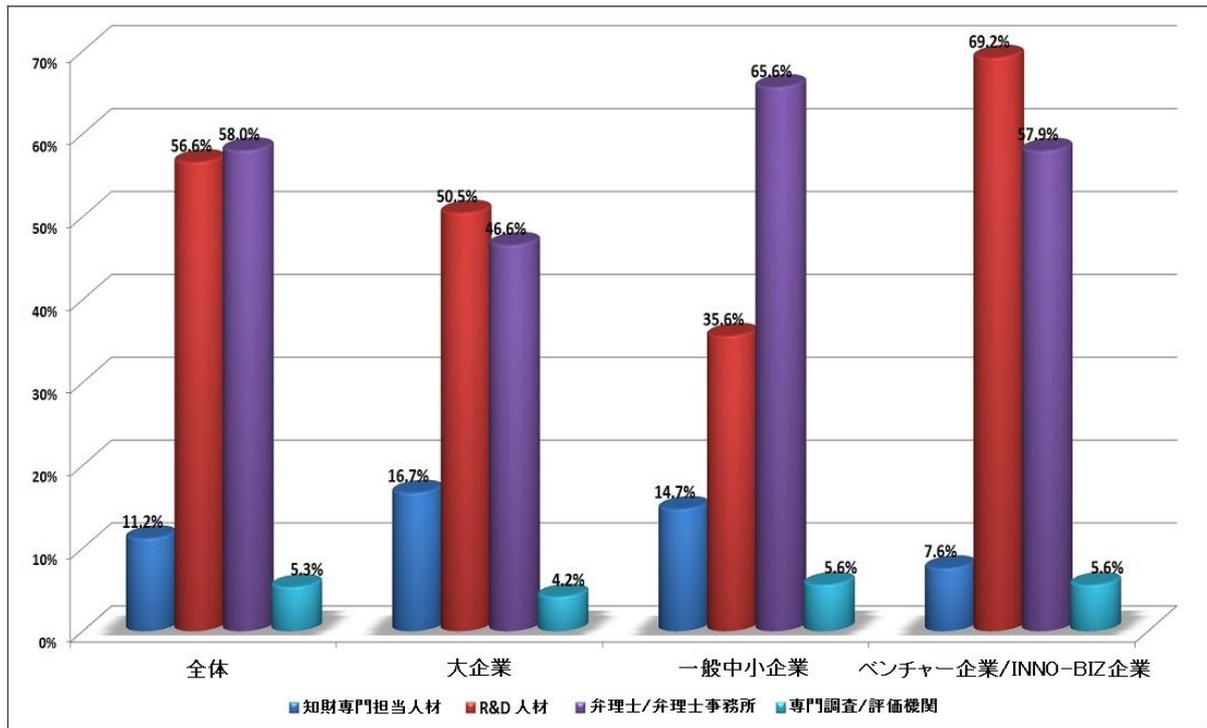
⁴⁰ 61件以上出願企業の場合予備評価を行う企業の比率は71.0%、全体発明件数のうち予備評価を行う比率は88.4%

全体企業の 33.3%(36.6%)が出願前の予備評価が必要であると答えている([図 2.23])。これは前述した研究開発企画段階における先行特許調査が必要であると答えた比率である 48.8%より低い数値である。予備評価が必要であると認識している企業の比率もまた出願件数が多い企業ほど高くなっている。特に、年 61 件以上出願する企業の 39.2%が出願前の予備評価がとても必要であると答えている。企業類型別では予備評価が必要であると答えた企業の比重は大企業が 42.3%とベンチャー/INNO-BIZ 企業の 35.2%より高い。



[図 2.23]予備評価実施の必要性

予備評価を担当している人材状況は[図 2.24]のとおりである。予備評価を実施している企業の場合の 56.6%(54.0%)は研究開発人材が該当業務を担当していると答えている。また、知的財産を専門的に担当している人材が該当業務を行っている企業の比重は全体の 11.2%(12.3%)を占めている。予備評価を外部の弁理士及び専門調査機関に託している場合は各々 58.0%(58.3%)と 5.3%(4.1%)となっている。



[図 2.24] 予備評価を行っている場合の実行人材

注. 複数回答

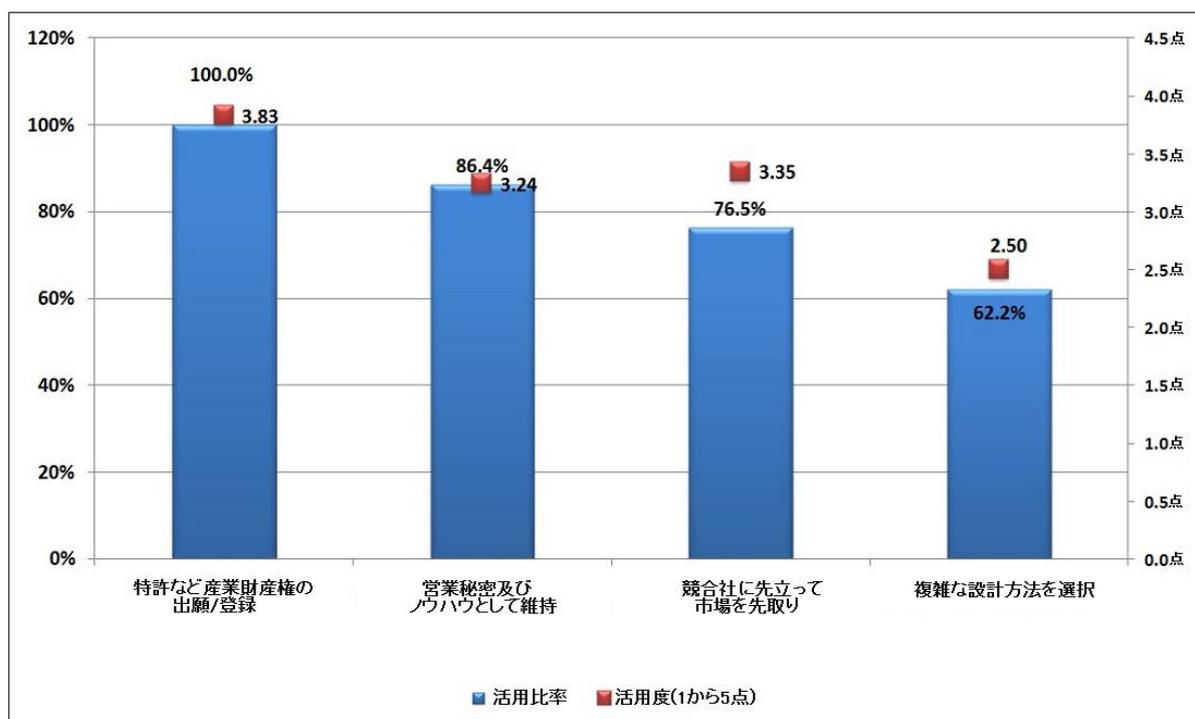
企業別では予備評価を知的財産専門担当人材が行っている比率は大企業が 16.7%と一般中小企業及びベンチャー企業に比べて高い。また、研究開発人材が直接予備評価を行っているとした比率はベンチャー企業が 69.2%と大企業及び一般中小企業より高いことがわかる。また、専門調査/評価機関に依頼する比率は一般中小企業(5.6%)及びベンチャー企業(5.6%)が大企業(4.2%)より多少高い。これは中小及びベンチャー企業が予備評価が行える専門人材を十分保有していないことを意味する。また、出願件数が多い企業ほど知的財産専門担当人材が予備評価を行っている比率が高くなっている。⁴¹

2. 研究開発成果の保護戦略

研究開発の成果に対する保護戦略として全体企業の 100.0%(同一)が特許など産業財産権の出願/登録を活用していることがわかった([図 2.25])。次に全体の 86.4%(90.9%)

⁴¹ 年平均61件以上出願企業の53.3%

と 76.5%(83.0%)が各々研究開発の成果を社内機密またはノウハウとして維持したり、競合社に先立って市場を先取りする戦略として活用していることがわかった。また、複雑な設計方式を採択することで研究開発の成果を保護する戦略も全体企業の 62.2% (68.9%)が活用していることがわかった。



[図 2.25]研究開発成果保護戦略の活用比率及び活用度

注. 複数回答

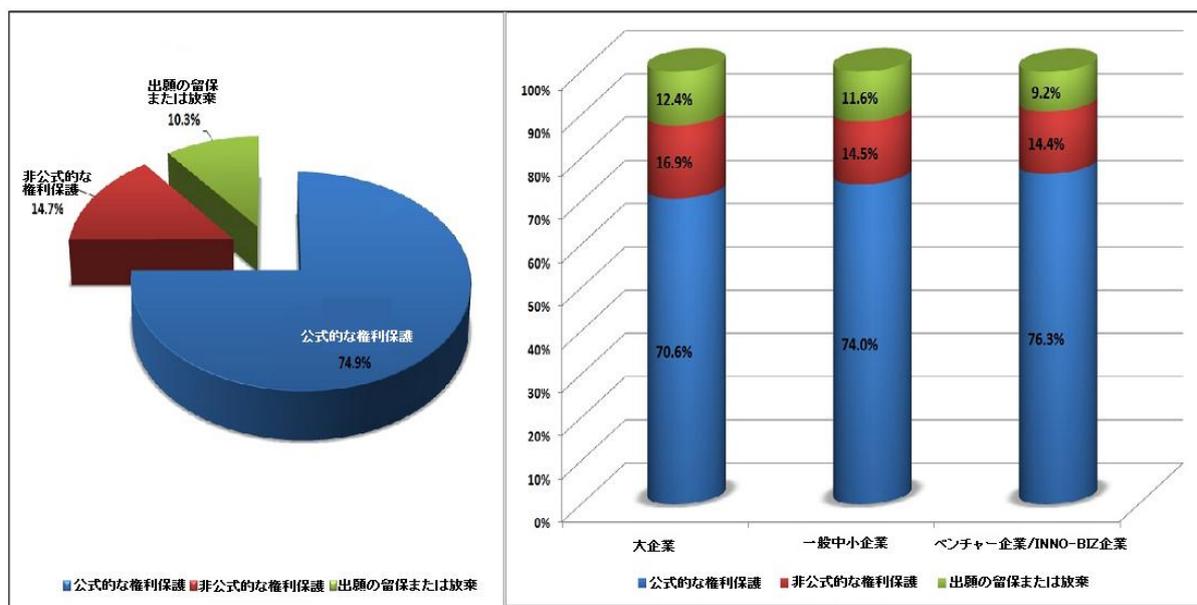
また、各研究開発成果の保護戦略に対してこれを活用している企業が感じている活用度⁴²もまた特許など産業財産権の出願/登録に対する活用度が 3.83 点(4.02 点)で最も高い。また、複雑な設計方式を採択することで研究開発成果を保護する戦略は 2.50 点(2.55 点)で、企業が認識している該当戦略に対する活用度が最も低い。企業類型別ではベンチャー企業は大企業及び一般中小企業に比べて各保護戦略を活用している比率と活用度が高いことがわかる。

[表 2.7]研究開発成果保護戦略の活用度

⁴² 研究開発成果の保護戦略に対する活用度は5点リッカート尺度で測定されている。

	企業全体	大企業	一般中 小企業	ベンチャー・ INNO-BIZ
特許など産業財産権の出願/登録	3.83	3.89	3.50	4.02
社内機密、ノウハウとして維持	3.24	3.41	2.91	3.38
競合社に先立ち市場を先取り	3.35	3.11	3.11	3.52
複雑な設計方法を採用	2.50	2.53	2.29	2.59

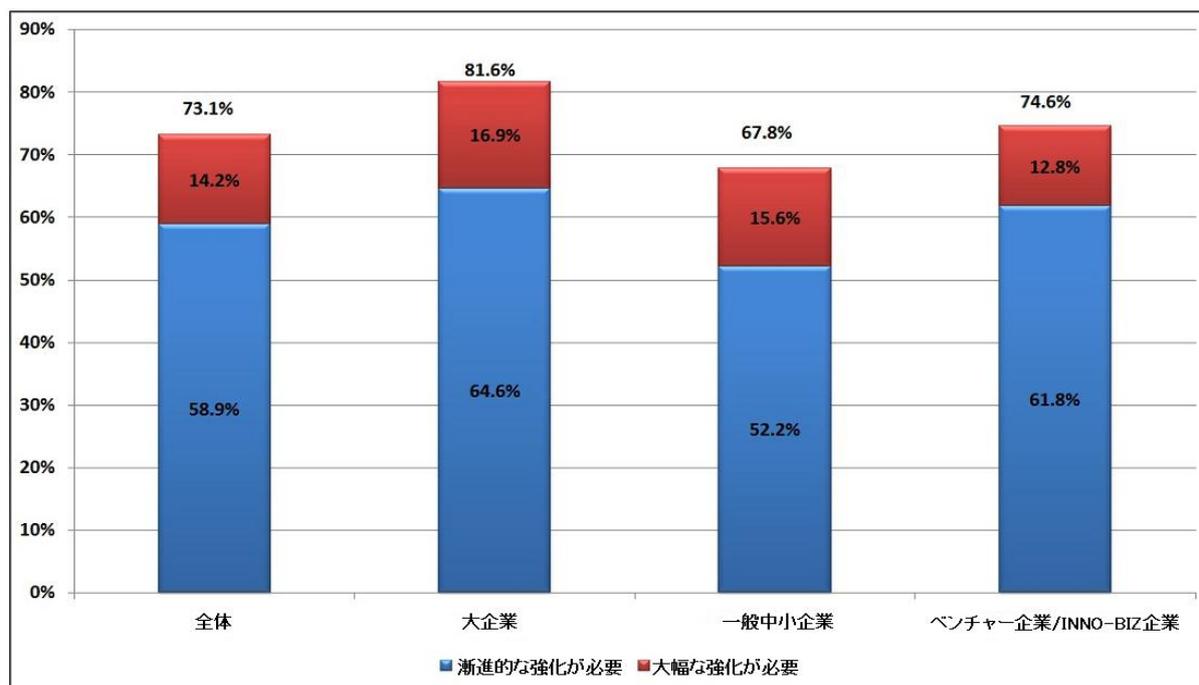
全体発明届出件数のうち予備評価を経て産業財産権の出願など公式的な権利保護手続きを進行するようになる比率は 74.9%(76.6%)となっている([図 2.26])。また、経済性や技術性の不足で出願を留保したり放棄する比率は 10.3%(9.6%)で、社内機密の維持など非公式的な権利保護を進める比率は 14.7%(13.8%)となっている。



[図 2.26]発明件数対比出願比率及び非公式的な権利保護の比率

このような比率は企業類型と出願件数による大差は見当たらない。但し、経済性や技術性の不足などで出願を留保または放棄する比率は大企業が 12.4%と一般中小企業 11.6%及びベンチャー企業 9.2%に比べて高い。

韓国企業の 73.1%(75.5%)は国内知的財産保護水準⁴³をより強化する必要があると答えている([図 2.27])。⁴⁴これは全体の 73.1%が現在の知的財産保護水準が適切な水準より低いと認識していることを意味する。このような比率は知的財産を相対的に多く保有している大企業(81.6%)と年平均出願件数 61 件以上である企業(85.4%)がより高くなっている。



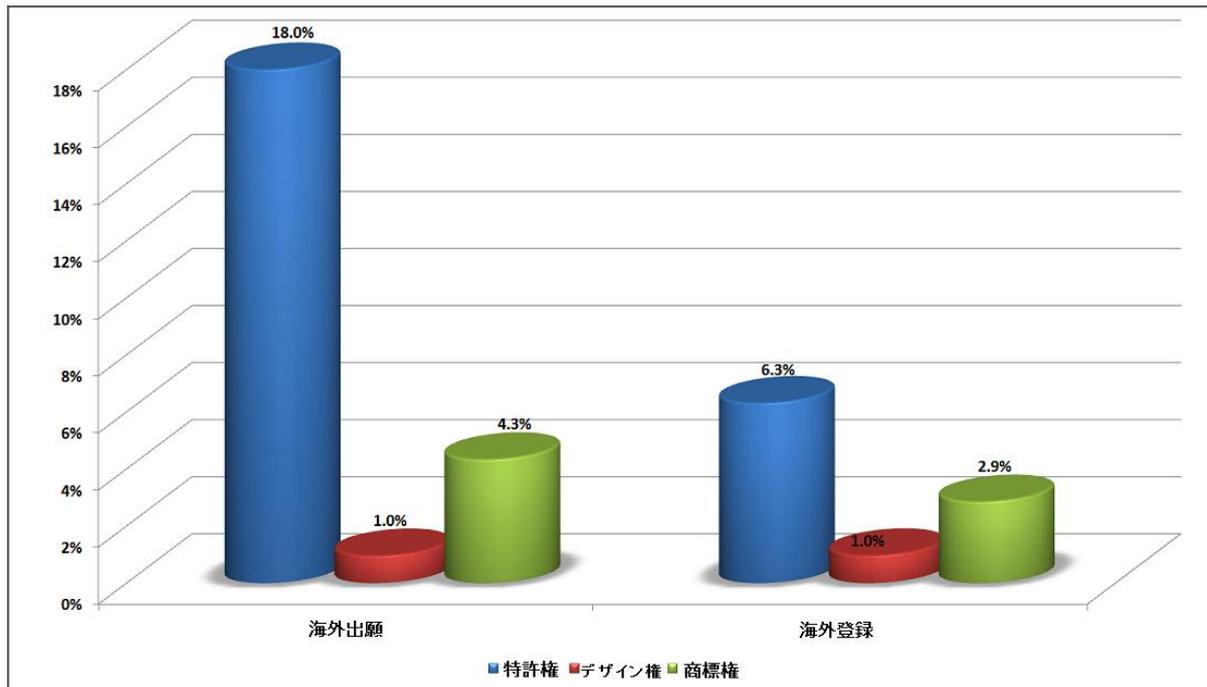
[図 2.27]国内知的財産保護水準に対する意見

3.産業財産権の海外出願/登録及び国内出願計画

2011 年に 1 件以上の特許権を海外に出願(PCT を含む)した企業は 18.0%(22.7%)となっている([図 2.28])。また、特許権を海外に登録した企業の比重は 6.3%(8.8%)となっている。特許権の他にデザイン権を海外出願及び登録した企業は各々 1.0%と 1.0%、商標権を海外出願及び登録した企業は各々 4.3%と 2.9%となっている。

⁴³ 特許制度のように創出された知的財産に権利を付与するシステムが効率的に運営されているかどうか、そしてこれを通じて成立された知的財産権が他人によって侵害された場合に対抗できる効率的な行政的及び司法的措置が十分取られているかどうかを意味する。

⁴⁴ 漸進的に強化(58.9%)、大幅に強化(14.2%)



[図 2.28]産業財産権の海外出願/登録企業の比重

企業類型別では 2011 年に特許権を海外出願及び登録した大企業は各々 30.1% (35.0%)、13.9%(21.0%)、一般中小企業は各々 7.7%(12.6%)、2.9%(4.7%)、ベンチャー企業は各々 21.7%(22.9%)、6.7%(6.9%)となっている。

一方、2012 年に比べて 2013 年に国内特許出願を拡大すると答えた企業は全体の 39.2%(45.6%)となっており、縮小すると答えた比率の 2.5%(2.3%)より遥かに高い水準であることがわかる([表 2.8])。企業類型別ではベンチャー企業が大企業及び一般中小企業に比べて全ての産業財産権の出願を拡大すると答えた比率が高くなっている。

[表 2.8]2012 年対比 2013 年の知的財産権出願計画

		全体	大企業	一般中小企業	ベンチャー・INNO-BIZ
特許	縮小	2.5%	1.1%	2.9%	2.6%
	拡大	39.2%	34.3%	28.0%	47.2%
実用新案	縮小	1.3%	1.1%	2.0%	0.8%
	拡大	14.7%	11.8%	13.0%	16.5%
デザイン	縮小	1.6%	1.1%	2.0%	1.5%

	拡大	13.6%	11.8%	12.5%	14.7%
商標	縮小	2.0%	1.6%	3.6%	1.0%
	拡大	13.1%	13.2%	11.9%	13.8%

業種別では化学産業と電気/電子産業に属している企業のうち特許出願の拡大を予想している比率が各々57.3%と52.5%と非常に高い。また、デザイン出願の拡大を予想している比率はその他製造業が28.3%、商標出願の拡大を予想している比率は農漁業/鉱業/飲食料/タバコ産業が28.9%と最も高い。

[表 2.9]産業財産権の国内出願の増減に影響を及ぼす要因

影響要因	全体	大企業	中小企業	ベンチャー企業
研究開発投資の増減による研究成果の変化	12.7%	17.4%	3.7%	17.1%
企業の事業戦略の変化(事業分野の多角化または事業構造調整など)	12.6%	17.1%	6.2%	15.5%
企業の産業財産権戦略の変化(量または品質中心の知的財産出願戦略、維持費用対比収益性戦略の変化など)	10.8%	17.4%	6.4%	12.0%
市場及び技術競争環境の変化(市場の拡大または縮小、新技術または新市場の出現など)	16.0%	12.4%	13.0%	18.6%
国内及びグローバル景気の変動(国内総生産の増減、物価及び為替の変化、世界金融危など機)	8.2%	4.5%	7.1%	9.7%
産業財産権出願環境の改善及び支援制度の強化(出願手数料の減免、手続きの簡素化、知財権創出支援制度など)	12.1%	15.6%	12.6%	10.9%

注. (%)は[(優先順位が最も高いと回答した機関数)/(総回答機関数)]×100(%)

一方、知的財産権出願の増減に最も大きな影響を及ぼす要因として全体企業の16.0%が「市場及び技術競争環境の変化」を挙げ、続いて12.7%が「研究開発投資の増減による研究成果の変化」を影響要因として挙げている。

企業類型別では、大企業の場合「企業の産業財産権戦略の変化」と「研究開発投資の増減による研究成果の変化」が知的財産権の出願に影響を及ぼすと答えた比率が最も高く、ベンチャー企業は「市場及び技術競争環境の変化」に大きな影響を受けると答えた比率が相対的に高い([表 2.9])。出願件数別では年出願件数が少ない企業であるほど「企業の産業財産権戦略の変化」に影響を受けると答えた比率が高い。

4.産業財産権の出願/審査/維持費用及び関連規定の状況

母集団に属している企業は 2011 年の 1 年間知的財産権の国内及び海外出願・審査・維持のために平均的に 1 億 2,059 万ウォン(1 億 5,834 万ウォン)を支出したこととなっている([表 2.10])。企業類型別では、大企業、一般中小企業、ベンチャー/INNO-BIZ 企業の平均支出額は各々 2 億 5,160 万ウォン、3,858 万ウォン、1 億 811 万ウォンとなっている。絶対的な金額の他に売上高対比出願維持費が占める比率⁴⁵を見ると、大企業は 0.05%、中小企業は 0.34%、ベンチャー企業は 3.17%となっている。細部支出事項を見ると、特に大企業の支出額において海外出願・審査・維持費用が占める比重が他企業に比べて相対的に高い。特異な点は国内出願・審査費用対比維持費用の比率は企業類型別に大きな差は見受けられないものの、海外出願・審査費用対比維持費用の比率は一般中小企業の場合 0.96%と大企業 0.36%、ベンチャー企業 0.12%に比べて高く、これに基づいて一般中小企業の全体出願・審査対比維持費用の比率も同じく高いことがわかった。⁴⁶

[表 2.10]知的財産の出願・審査・維持費用

	国内		海外		出願・審査・維持費用の合計
	出願・審査 ⁴⁷	維持 ⁴⁸	出願・審査	維持	

⁴⁵ (出願維持費/売上高)*100で計算する。

⁴⁶ 一般中小企業の場合0.64%、大企業の場合0.4%、ベンチャー企業の場合0.21%

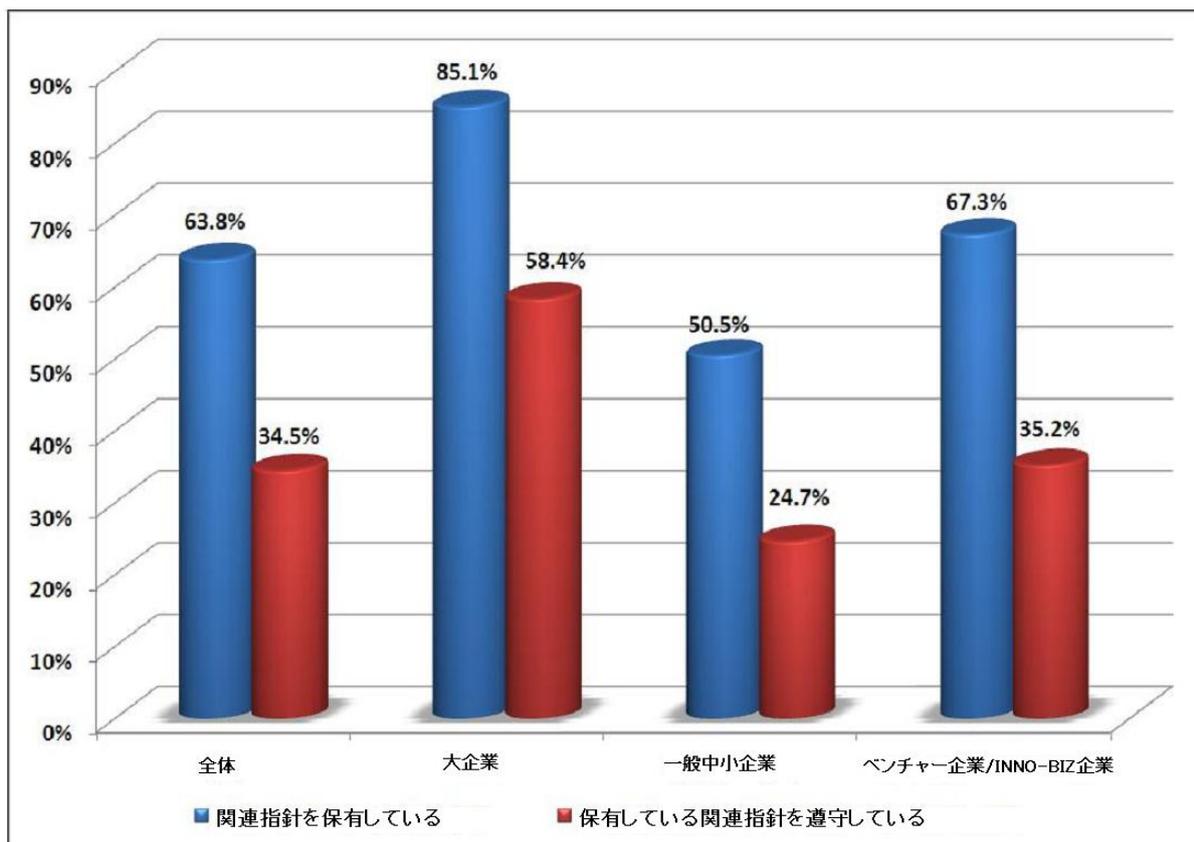
⁴⁷ 出願/審査費用は産業財産権の出願手数料、審査請求料、弁理士費用、決定系審判(特許

全体	2,133 万ウォン	1,012 万ウォン	7,140 万ウォン	1,775 万ウォン	1億 2,059万ウォン
大企業	4,457 万ウォン	2,292 万ウォン	1億 3,508 万ウォン	4,902 万ウォン	2億 5,160万ウォン
一般中小企業	1,376 万ウォン	555万ウォン	981万ウォン	945 万ウォン	3,858万ウォン
ベンチャー /INNO-BIZ企業	2,038 万ウォン	999万ウォン	6,932 万ウォン	843 万ウォン	1億 811万ウォン

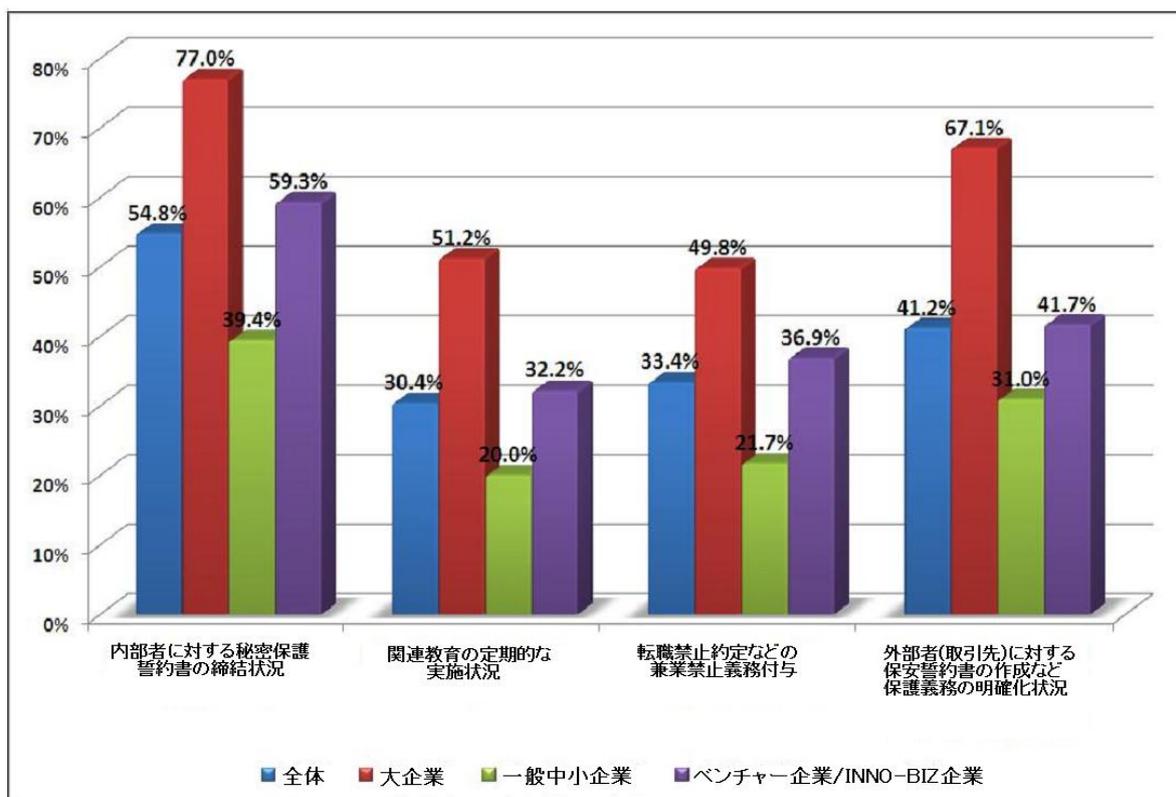
全体企業の 63.8%(68.8%)に該当する企業は営業秘密の管理及び技術流出防止指針を保有しているが、34.5%(38.9%)だけがこれを遵守していることがわかった([図 2.29])。逆にいえば、全体企業の 29.3%は関連指針は保有しているものの遵守しなければならないという認識が薄く、36.2%は関連指針を保有していないことを意味する。企業類型別では大企業の 85.1%と 58.4%が関連指針を保有及び遵守すると答え、最も高い。

出願に対する拒絶決定など審査官の処分不服に不服して請求する審判)にかかった費用

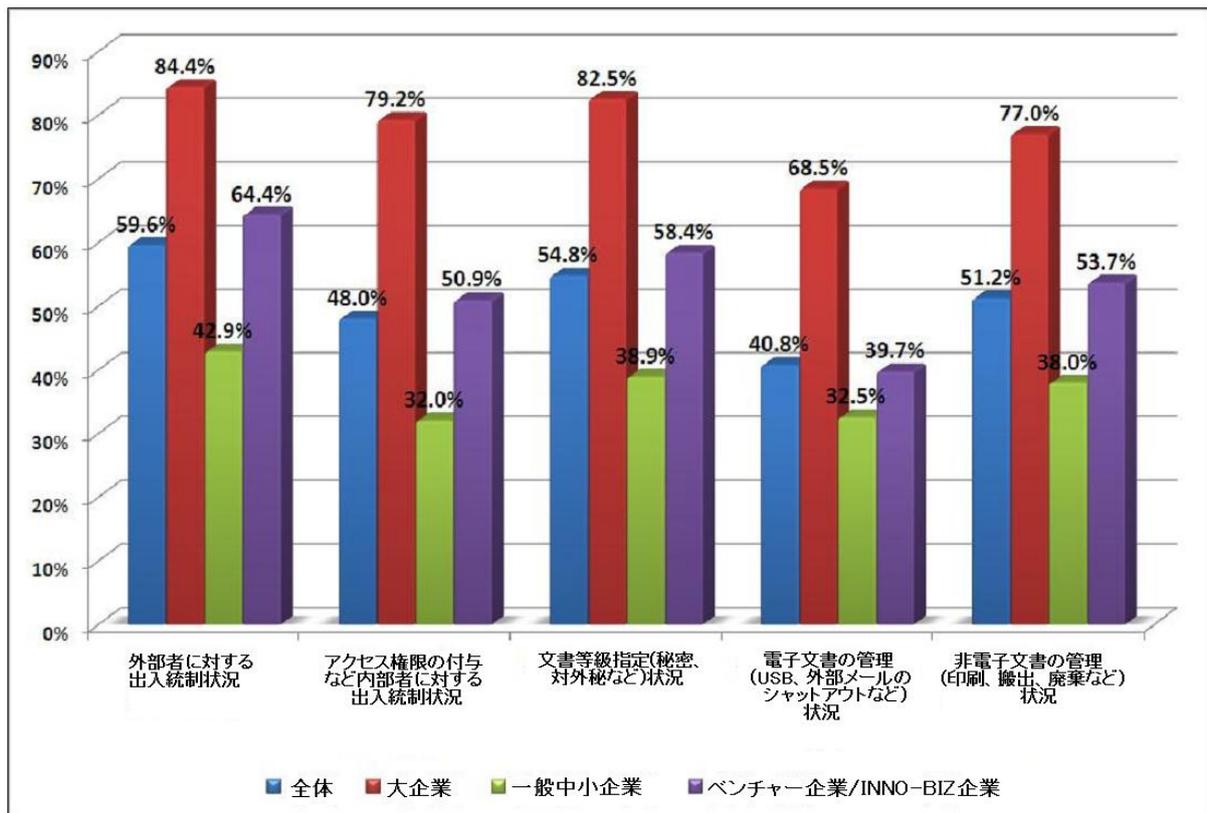
⁴⁸ 維持費用は産業財産権の登録と権利維持にかかる金額(登録料と維持年金)



[図 2.29]営業秘密の管理及び技術流出防止指針の保有・遵守状況



[図 2.30]営業秘密管理及び技術流出のための人材管理状況



[図 2.31]営業秘密管理及び技術流出防止のための物的管理状況

5.効果的な知的財産保護のために必要な政策支援

知的財産を効果的に保護するため「産業財産権の出願と登録にかかる費用の減免」が必要であると答えた比率は 59.7%と最も高く、「知的財産侵害に対するコンサルティング支援と共同取締り」が必要であると答えた比率は 53.2%と最も低い([表 2.11])。

企業類型別では「海外出願関連の情報提供」が必要であると答えた比率は他企業類型に比べてベンチャー企業が 60.7%と最も高く、「産業財産権の出願と登録にかかる費用の減免」及び「知的財産権侵害に対する強力な処罰基準の制定」、「知的財産侵害に対するコンサルティング支援と共同取締り」が必要であると答えた比率は大企業が 66.7%、63.5%、60.6%と最も高い。

[表 2.11]効果的な知的財産保護のための政策支援の必要性

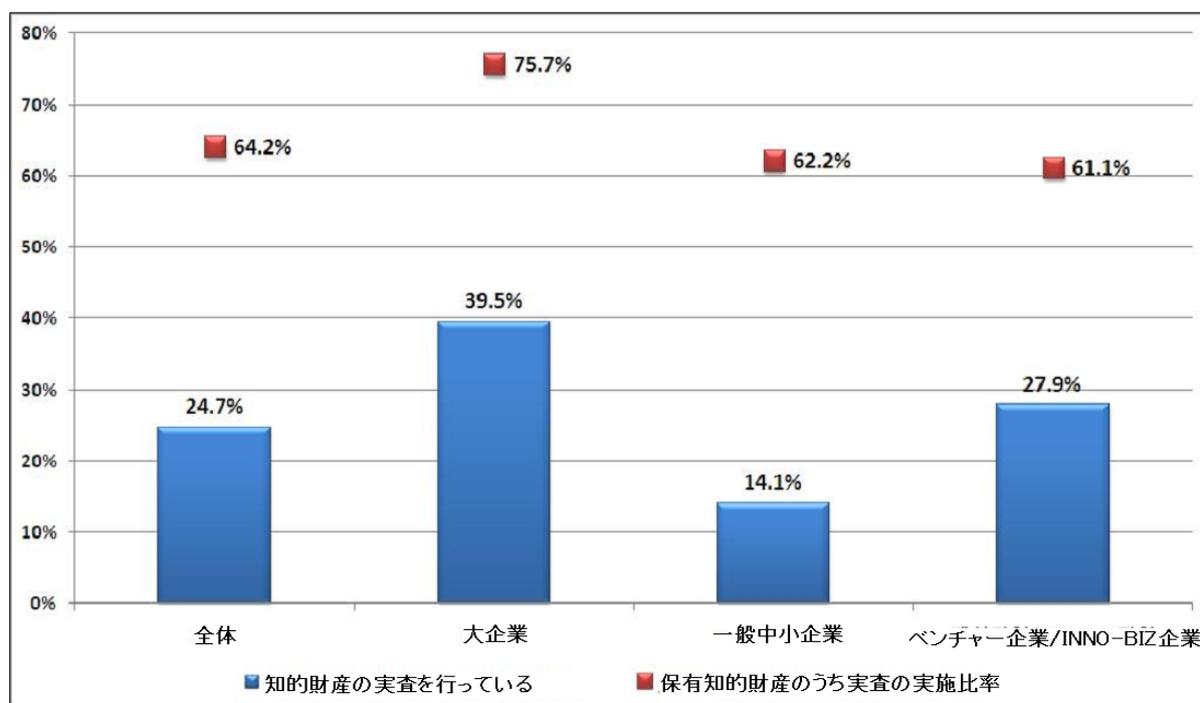
	企業全体	大企業	一般中小企業	ベンチャー・ INNO-BIZ
産業財産権の出願と登録にかかる 費用の減免	59.7%	66.7%	46.4%	66.4%
海外出願関連情報の提供	53.7%	56.7%	41.3%	60.7%
知的財産権侵害に対する 強力な処罰基準の制定	56.2%	63.5%	48.8%	59.1%
知的財産権害に対する コンサルティング支援と共同取締り	53.2%	60.6%	43.0%	57.9%

注. (%)は 5 点尺度(1 : 必要性が最も低い、5 : 必要性が最も高い)で[(4 点と 5 点と答えた企業数)/(総回答機関数)]×100(%)

第4節 知的財産の活用

1.知的財産実査

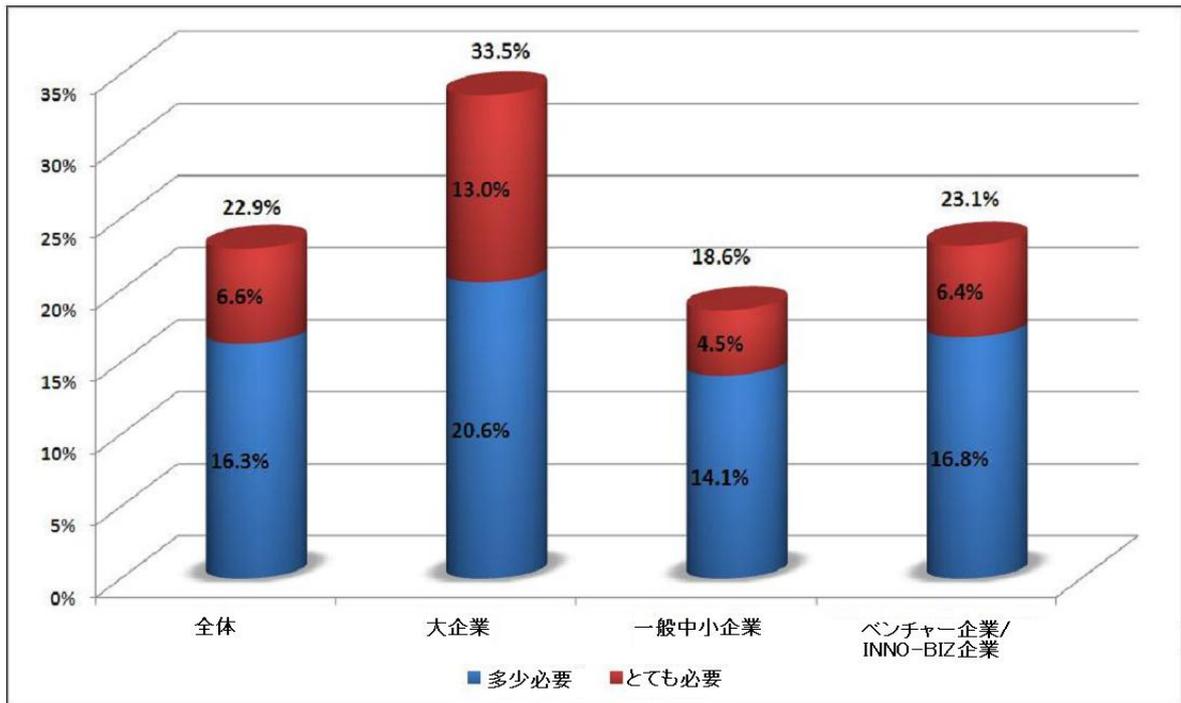
保有している知的財産に対する実査及び評価⁴⁹を行っている企業の比率は全体の24.7%(28.0%)となっている([図 2.32])。これは先行特許調査及び予備評価を行っている企業の比率より低い。知的財産実査を行っていると答えた企業は平均的に保有している知的財産のうち64.2%(65.7%)に対して実査を行っていることがわかる。



[図 2.32]知的財産実査の実施状況

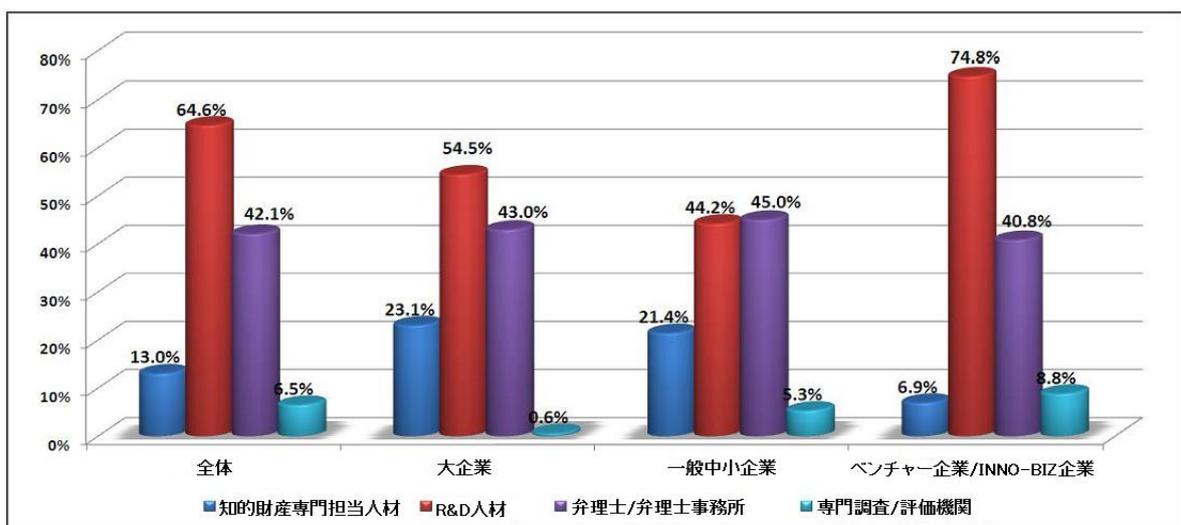
企業類型別では、大企業と多出願企業において知的財産に対する実査を行っている企業の比率と保有知的財産のうち実査を行っている比率がいずれも高いことがわかる。業種別ではその他製造業に属している企業の42.5%が知的財産の実査を行っており、その他産業より高く、その他サービス業は10.3%と最も低い。

⁴⁹ 特許などの維持/放棄の決定、事業化有望技術及び移転対象技術などを発掘するために保有している知的財産の価値を把握することを意味する。



[図 2.33]知的財産実査の必要性

保有している知的財産に対する実査が必要であると回答した企業の比率は全体の22.9%(28.1%)となっている([図 2.33])。すなわち、全体企業の約77%が知的財産実査の必要性に対して認識していないことを物語っている。大企業の場合33.5%が知的財産の実査が必要であると答え、特にとても必要であると答えた企業の比率は大企業が13.0%と最も高くなっている。また、多出願企業であるほど該当業務が必要であると答えた企業の比率が高い。



[図 2.34]知的財産実査を行っている場合の実行人材

注. 複数回答

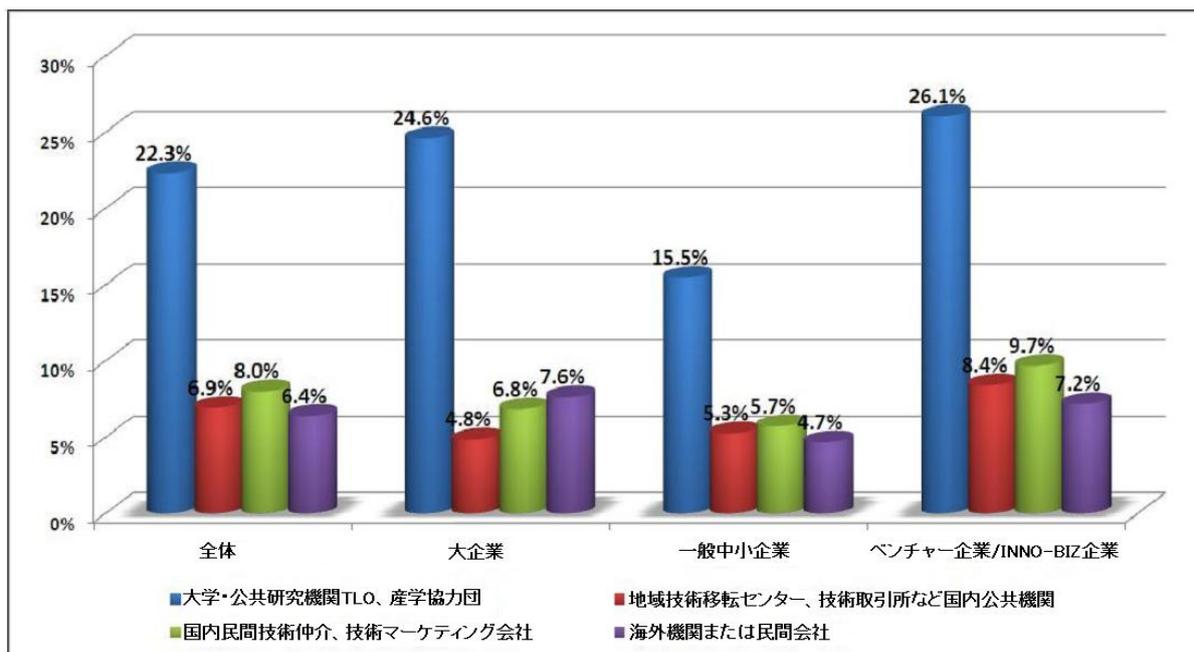
知的財産実査を行っている企業のうち 64.6%(63.3%)は研究開発人材が直接該当業務を担当していること答えている([図 2.34])。知的財産専門担当人材が該当業務を行っていると答えた企業は 13.0%(15.7%)となっており、弁理士/弁理士事務所及び専門機関に託す場合は各々42.1%(40.6%)と 6.5%(3.6%)となっている。

企業類型別では、知的財産専門担当人材が業務を行っている比率は大企業が 23.1%、年平均 61 件以上出願企業が 50.6%と高いことがわかった。また、弁理士、専門調査/評価機関など外部人材を活用している比率は大企業より一般中小企業及びベンチャー企業が高いことがわかった。

2.知的財産の活用戦略

最近 3 年間技術取引及び技術マーケティングのための技術取引機関に業務を依頼、もしくは協約を締結した企業の比率は[図 2.25]のとおりである。全体企業の 22.3%(25.5%)が大学・公共研究機関の技術移転専門担当組織(TLO)及び産学協力団に業務を依頼したことがあると答えている。また、地域技術移転センターなど国内公共機関、国内民間技術仲介会社、海外機関に業務を依頼した企業の比重は各々6.9%(6.6%)、8.0%(7.6%)、6.4%(8.2%)となっている。

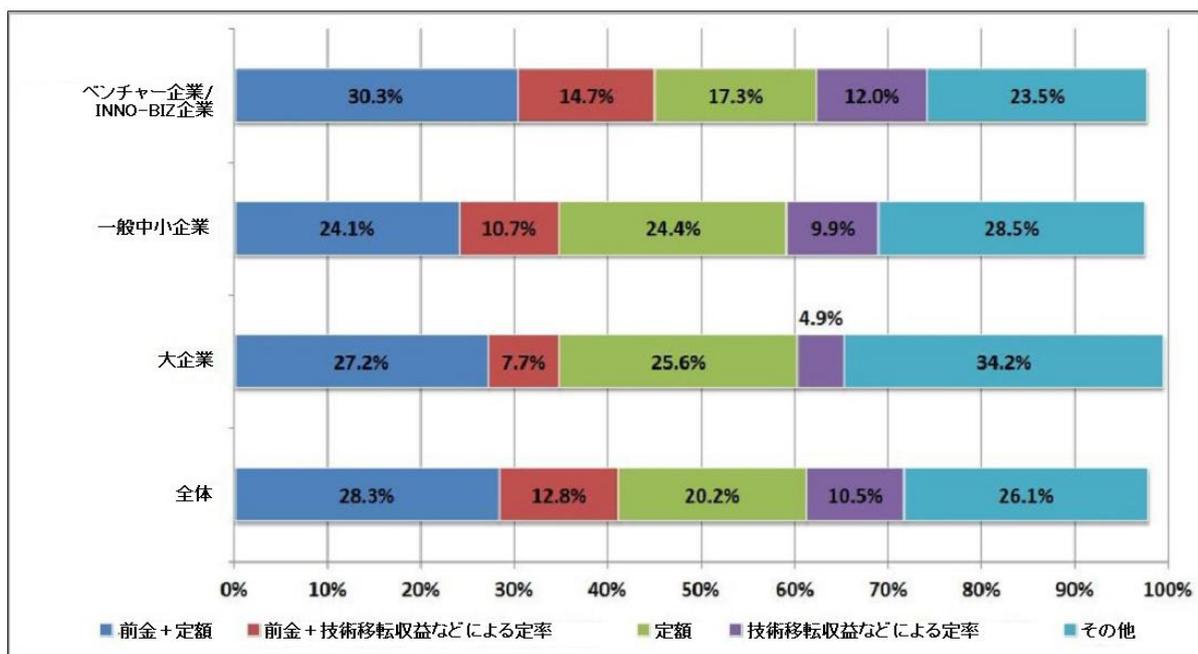
企業類型別では大学・公共研究機関の技術移転専門担当組織(TLO)及び産学協力団と海外機関/会社に依頼した大企業の比率は各々24.6%、7.6%と他企業類型に比べて高い。また、地域技術移転センターなど国内公共機関と国内民間技術マーケティング会社に依頼した比率はベンチャー企業が各々8.4%と 9.7%で大企業及び一般中小企業に比べて高いことがわかる。



[図 2.35]最近 3 年間技術取引機関に対する業務依頼及び締結状況

技術取引機関などに業務を依頼した場合、主な費用支払い方法は調査/マーケティング費用など活動費(前金)と成功報酬(定額)が混ざった形態が全体の 28.3%(26.5%)で最も高い比重を占めている([図 2.36])。また、成功報酬として定額を支給する場合は 20.2%(20.5%)、活動費(前金)と技術移転収益などによる定率の成功報酬が混ざった形態で支給する場合は 12.8%(17.5%)となっている。一方、技術移転収益などによる定率の成功報酬のみ費用を支給する場合は 10.5%(10.7%)で最も低い。

企業類型別では、大企業は活動費(前金)と成功報酬(定額)が混ざった形態で費用を支払った比率が全体の 27.2%でその他を除けば最も高く、ベンチャー企業は活動費(前金)と技術移転収益などによる定率の成功報酬が混ざった形態で支給した場合が 14.7%、技術移転収益などによる定率の成功報酬のみ支給した場合が 12.0%で他企業類型に比べて高い。これは技術移転費用を支給するに当たって、大企業は定額の形態を好み、ベンチャー企業は技術移転収益などによる定率形態を好んでいるものと解釈できる。



[図 2.36]技術取引機関などに業務を依頼した場合の主な費用支給方法

企業が保有している知的財産取引のために IP-mart⁵⁰など国内オンライン技術取引システムを活用している企業の比率は全体の 17.0%(17.6%)となっている([表 2.12])。国内オンライン取引システムを活用している企業のうち活用度が比較的に高いと肯定的に答えた比率は 17.6%(14.9%)となっている。

企業類型別では、ベンチャー企業の場合国内オンライン及びオフライン取引システムを活用している比率が他企業類型に比べて高く、海外オンライン及びオフライン取引システムの活用率も高い方である。しかし、活用企業に限って活用度の調査結果の活用度は比較的に低い方である。

[表 2.12]国内技術取引システムの活用度

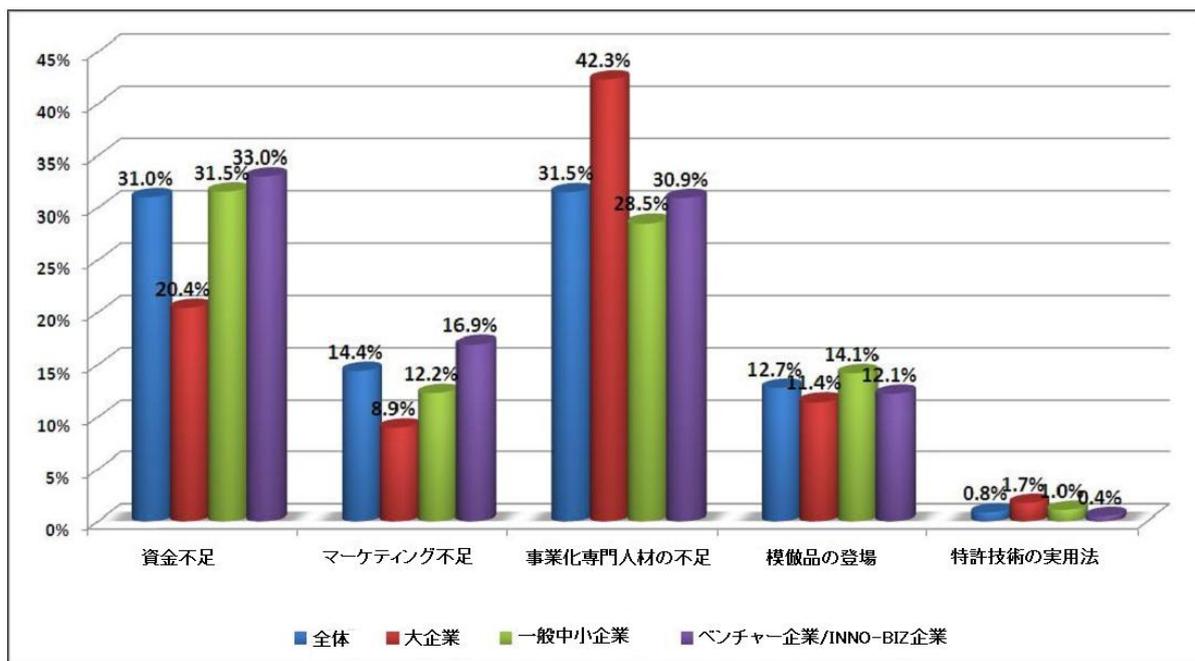
⁵⁰ IP-martは特許庁が運営しているインターネット特許技術市場であり、特許技術の技術移転・取引及び事業化など関連情報を提供し、利用者が自律的に技術取引に参加できるよう、オンライン上で特許技術取引を仲介する専門ポータルサイト(<http://www.patentmart.or.kr/>)である。

		企業全体	大企業	一般中小企業	ベンチャー・INNO-BIZ
国内オンライン取引システム	活用企業	17.0%	10.8%	14.7%	19.8%
	活用度が比較的に高い	17.6%	13.3%	26.1%	14.3%
国内オフライン取引システム	活用企業	19.2%	18.5%	15.1%	21.9%
	活用度が比較的に高い	11.0%	8.2%	8.6%	12.6%
海外オンライン取引システム	活用企業	13.5%	9.3%	11.2%	15.9%
	活用度が比較的に高い	5.6%	3.9%	7.8%	4.9%
海外オフライン取引システム	活用企業	13.3%	10.4%	11.1%	15.3%
	活用度が比較的に高い	5.8%	4.3%	7.5%	5.2%

注. 「活用度が比較的に高い」は 5 点尺度(1: 活用度が低い、5: 活用度が高い)で[(4と 5 で回答した企業数)/(活用した経験のある企業数)]×100(%)

特許技術移転博覧会など国内オフライン取引システムを活用している企業の比率は 19.2%(18.6%)でオンライン取引システムより多少高い。また、実際オフラインシステムを活用している企業のうち活用度が高いと答えた比率は 11.0%(9.4%)でオンライン取引システムより低い。企業類型別ではベンチャー企業の中でオフライン取引システムの活用率及び活動度が高いと答えた比率が各々 21.9%と 12.6%で他企業より高いことがわかる。

企業にとって特許技術の事業化における最も大きな問題として、全体の 31.5% (31.1%)が事業化専門人材の不足と答えている([図 2.37])。また、資金不足によって事業化が難しいと答えた企業も 31.0%(29.6%)を占めている。



[図 2.37]特許技術の事業化における最大の問題

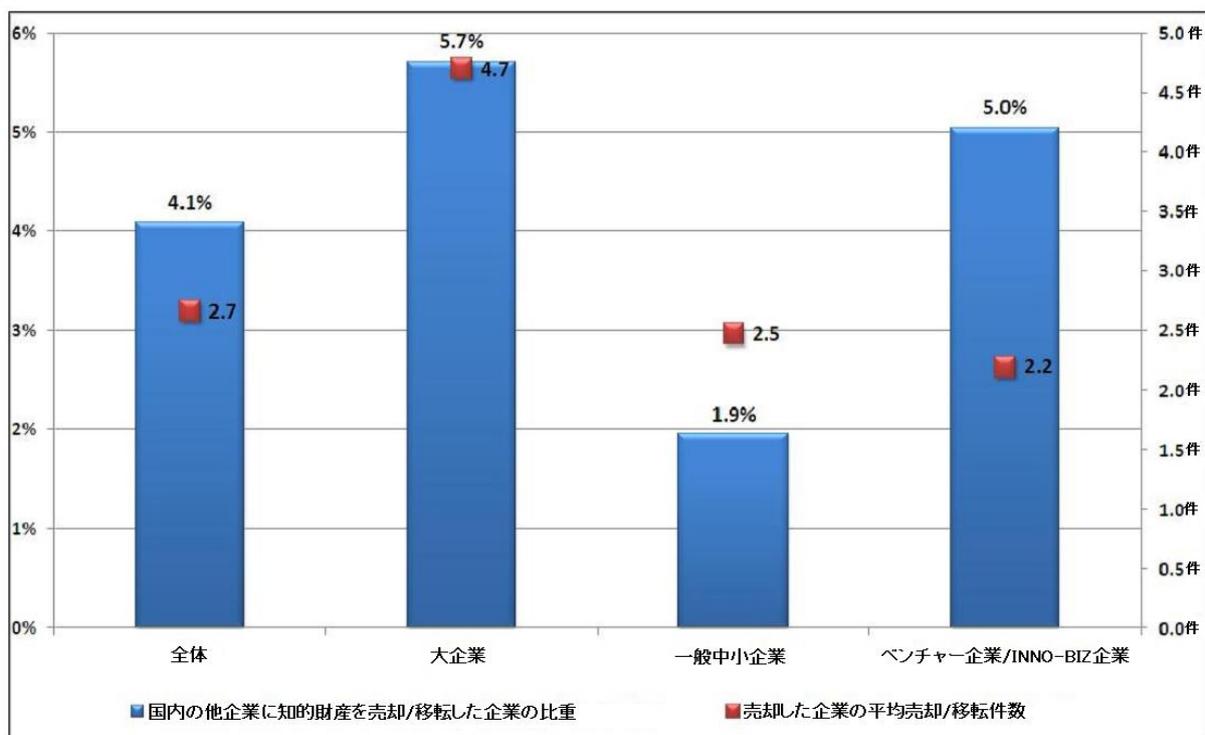
事業化における問題点として資金不足を挙げた企業の比率は大企業(20.4%)、一般中小企業(31.5%)、ベンチャー企業(33.0%)の順で増加しており、事業化専門人材の不足を指摘した比率は一般中小企業(28.5%)、ベンチャー企業(30.9%)、大企業(42.3%)の順で増加していることがわかる。

業種別では、資金不足が最も大きなネックとなっていると答えた比率はその他製造業が 46.2%と最も高く、模倣品の登場が最大のネックであると答えた比率は繊維/衣服/靴産業が 22.3%と最も高い。

3.知的財産権の売却/移転及び活用状況

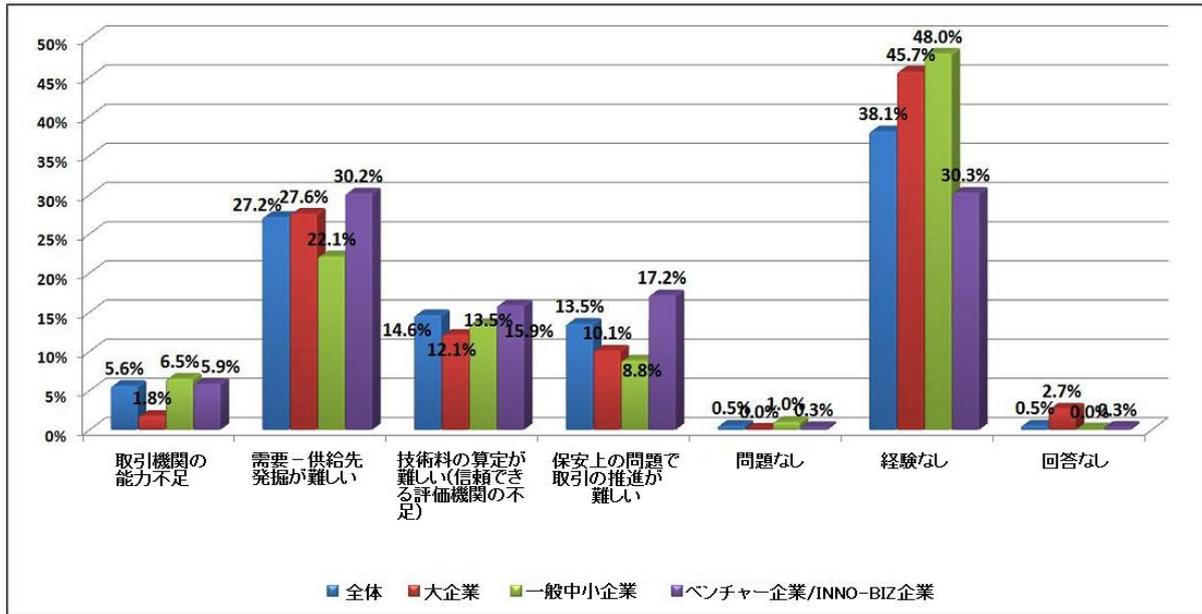
2011年の1年間保有している知的財産を国内の他企業などに移転した企業の比率は4.1%(5.2%)となっており、知的財産を移転した企業の平均移転件数は2.7件(4.4件)となっている([図 2.38])。知的財産を移転した企業の比率は企業類型別に大きな差は見当たらないが、大企業が5.7%(5.4%)で最も高く、ベンチャー企業5.0%(5.7%)、一般中小企業1.9%(3.8%)となっている。

業種別ではその他サービス業が知的財産売却/移転比率が 6.8%と最も高く、出願件数が多い企業ほど知的財産を売却/移転した企業の比率(14.9%)及び平均売却/移転件数(7.2 件)が高いことがわかる。

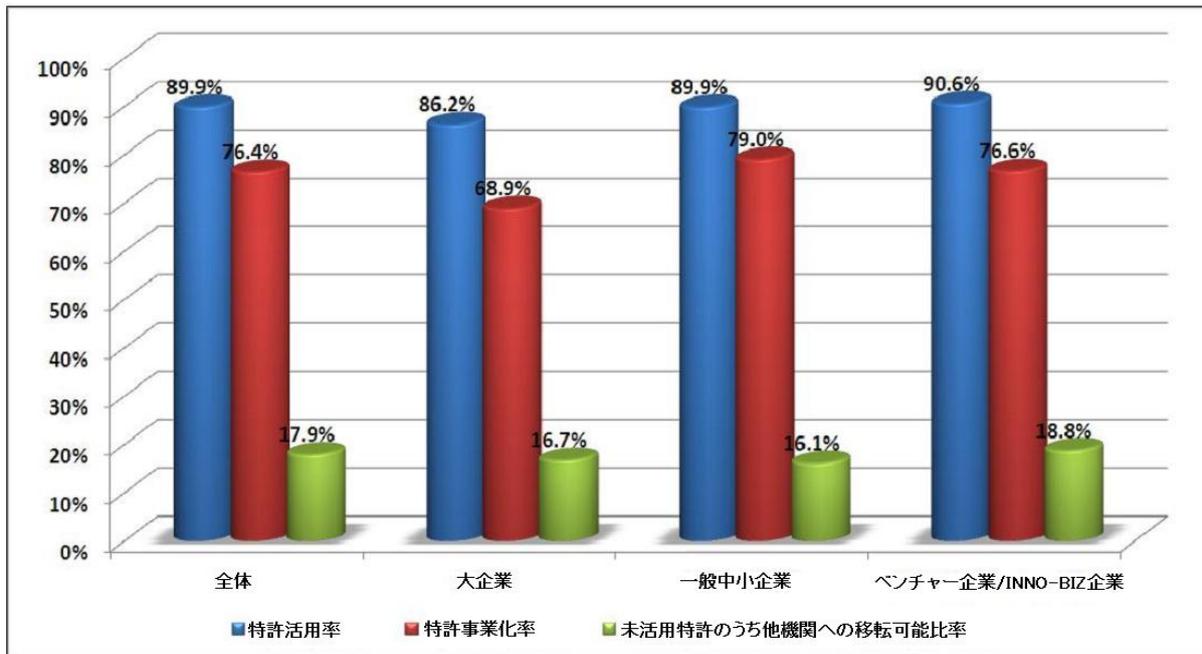


[図 2.38]知的財産の売却・移転状況

企業全体の平均売却/移転件数は 0.11 件となっており、このうち実施許諾を通じて移転件数は 0.04 件、売却/譲渡を通じて移転された件数は 0.06 件、最後にクロスライセンスや特許プールなどを通じて相互実施または共有形態で移転された件数は 0.01 件となっている。企業類型別では、大企業と中小企業は売却/譲渡を通じた移転件数が各々0.28 件のうち 0.21 件、0.05 件のうち 0.03 件で最も多く、ベンチャー企業は実施許諾を通じた移転件数が 0.11 件のうち 0.06 件で最も多い。知的財産の売却/移転時の最も大きなネックとしては、全体企業の 38.1%が関連経験がないと答え、27.2%が必要・供給先発掘の難しさを挙げている。



[図 2.39]知的財産の売却または移転する上で最も大きな問題



[図 2.40]特許権の活用率及び事業化率

注. 個別企業の活用率及び事業化率の平均である。

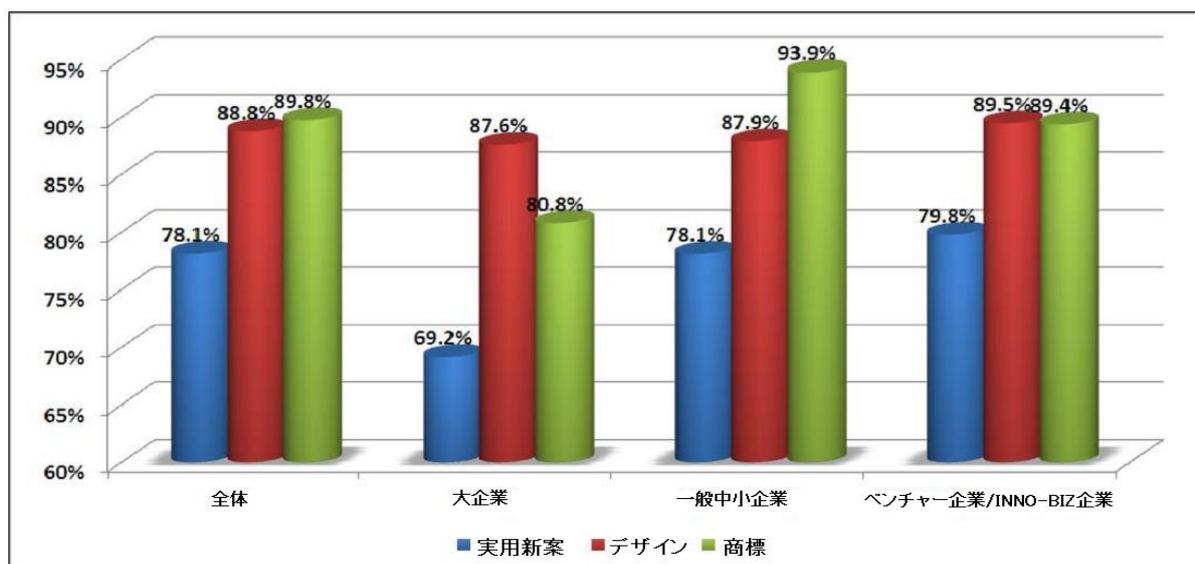
韓国企業が保有している特許権の平均活用率⁵¹と平均事業化率⁵²は各々 89.9% (88.5%)と 76.4%(74.1%)となっている([図 2.40])。これは全体特許のうち防御的な目

⁵¹ 保有している特許のうち①製品やサービスの生産、工程の改善に活用していたり、②収益創出などを目的として他機関に移転した場合または③生産活動や技術移転などには直

的として活用される比率が 13.5%(14.4%)で、未活用率が 10.1%(11.5%)であることを意味する。また、未活用特許の中で他機関に移転が可能な特許は 17.9%(19.7%)となっている。

企業類型別では、活用率と事業化率いずれも大企業がベンチャー企業や一般中小企業より低い。一方、防御的な目的で保有している特許の比率は大企業が 17.4%(18.3%)で一般中小企業 10.8%(10.8%)とベンチャー企業 14.0%(14.6%)に比べて高いことがわかる。

特許権の他に実用新案権、デザイン、商標の事業化率は各々78.1%(77.2%)、88.8%(88.3%)、89.8%(88.8%)となっている([図 2.41])。実用新案権、デザイン権、商標権の場合は特許権とは異なり、活用率と事業化率の間で大きな差は見当たらない。これはこの権利の場合は防御的な目的で保有する比率がとても低いことを意味する。



[図 2.41]その他産業財産権の事業化率

注. 個別企業の事業化率の平均である。

接活用していないものの戦略的な目的(核心技術の防御、特許訴訟の防止、国家レベルでの必要性など)で保有、活用している特許の比率

⁵² 保有している特許のうち防御的な目的で活用している場合を除いて製品やサービスの生産、工程改善に活用していたり、収益創出などを目的として他機関に移転した特許の比率

全体企業が保有している特許権全体の中で現在活用及び事業化されている比率⁵³は各々79.4%(82.6%)と 56.5%(60.4%)となっている。企業類型別では大企業の活用率と事業化率が各々77.1%(79.2%)と 52.2%(53.2%)で一般中小企業及びベンチャー企業に比べて低いことがわかる([表 2.13])。

[表 2.13]回答企業が保有している特許の活用率及び事業化率

企業区分	保有件数	活用件数	事業化件数	活用率	事業化率
大企業	42,681	32,890	22,292	77.1%	52.2%
中小企業	3,214	2,951	2,299	91.8%	71.5%
ベンチャー/INNO-BIZ	9,521	8,174	6,746	85.9%	70.9%
全体	55,416	44,015	31,337	79.4%	56.5%

4.知的財産を効果的に活用するために必要な政策支援

該当政府政策が知的財産を効果的に活用するために必要であると回答した企業の比率は[表 2.14]のとおりである。「偽造品及び模倣品の取締り強化」が必要と答えた比率は全体の 59.6%と最も高い。また、「新技術製品の販路支援及び活動支援の必要性」も 59.2%の企業が必要であると答えている。

企業類型別では、大企業と一般中小企業は「偽造品及び模倣品の取締り強化」政策に対する支援が必要であると答えた比率が各々64.4%、56.3%と他支援政策に比べて高い。ベンチャー企業の場合、「新技術製品の販路支援及びマーケティング活動支援」及び「新技術事業化のための中小/ベンチャー創業支援」政策に対する必要性が高いと答えた比率が同じく 65.5%と他支援政策に比べて高い。

[表 2.14]効果的な知的財産活用のための政策支援の必要性

⁵³ 回答した企業全体が保有する特許を合算し、この中で活用されている比率と事業化されている比率を算出したものである。したがって、多出願企業の活用率と事業化率が加重反映されているといえる。

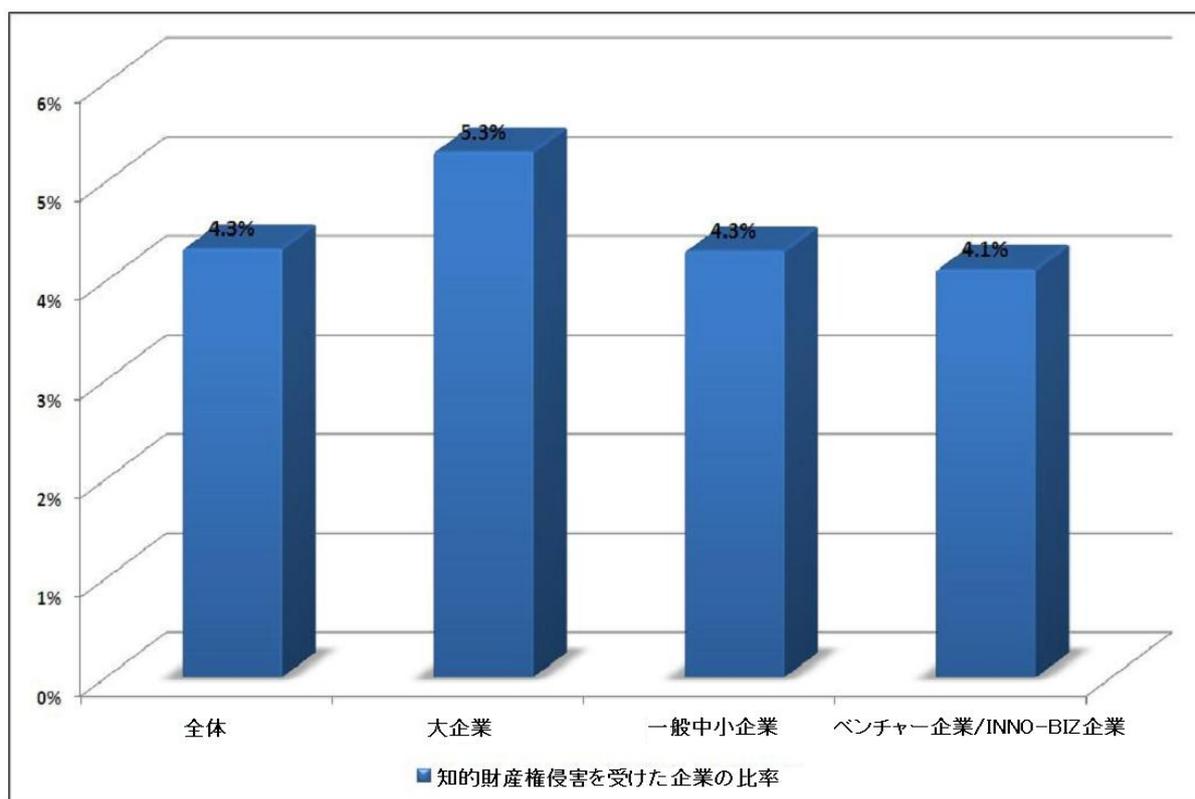
	企業 全体	大企業	一般中小企業	ベンチャー・ INNO-BIZ
新技術製品の販路支援及び マーケティング活動の支援	59.2%	53.5%	51.0%	65.5%
偽造品及び模倣品の取締り強化	59.6%	64.4%	56.3%	60.6%
新技術事業化に向けた中小/ベンチャー 創業支援	58.6%	49.1%	50.8%	65.5%
特許技術の取引、流通システムの改善	50.2%	58.6%	48.0%	49.8%
優秀技術輸出支援	57.3%	56.0%	47.8%	63.3%
地域知識センターなどを通じた出願か ら事業化までの特許総合コンサルティ ング支援	56.6%	59.8%	48.7%	60.8%

注. (%)は 5 点尺度(1: 必要性が最も低い、5: 必要性が最も高い)で[(4 点と 5 点で回答した企業数)/(総回答機関数)]×100(%)

第5節 知的財産の侵害及び紛争

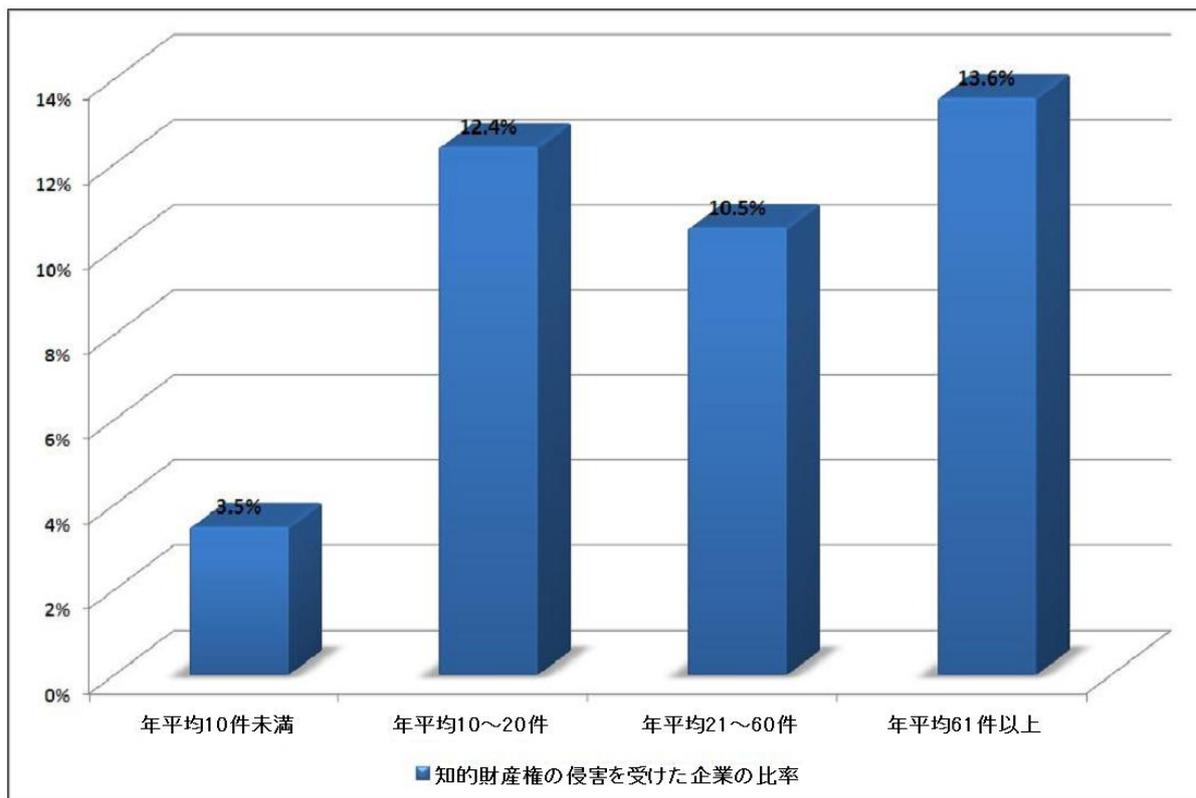
1.知的財産権の侵害及び被害規模

2011年に1件以上の知的財産権⁵⁴侵害を受けた企業は全体の4.3%(6.7%)を占めている([図 2.42])。企業類型別では大企業 5.3%(9.5%)、一般中小企業の4.3%(6.9%)、ベンチャー企業の4.1%(5.9%)が知的財産権侵害を受けたことがわかった。産業財産権の出願規模によっては年平均10件未満を出願する企業は3.5%(3.4%)である一方、年平均10~20件を出願する企業のうち知的財産侵害を受けた企業は10.5%(15.2%)、61件以上出願した多出願企業の比率は13.6%(10.6%)となっている。

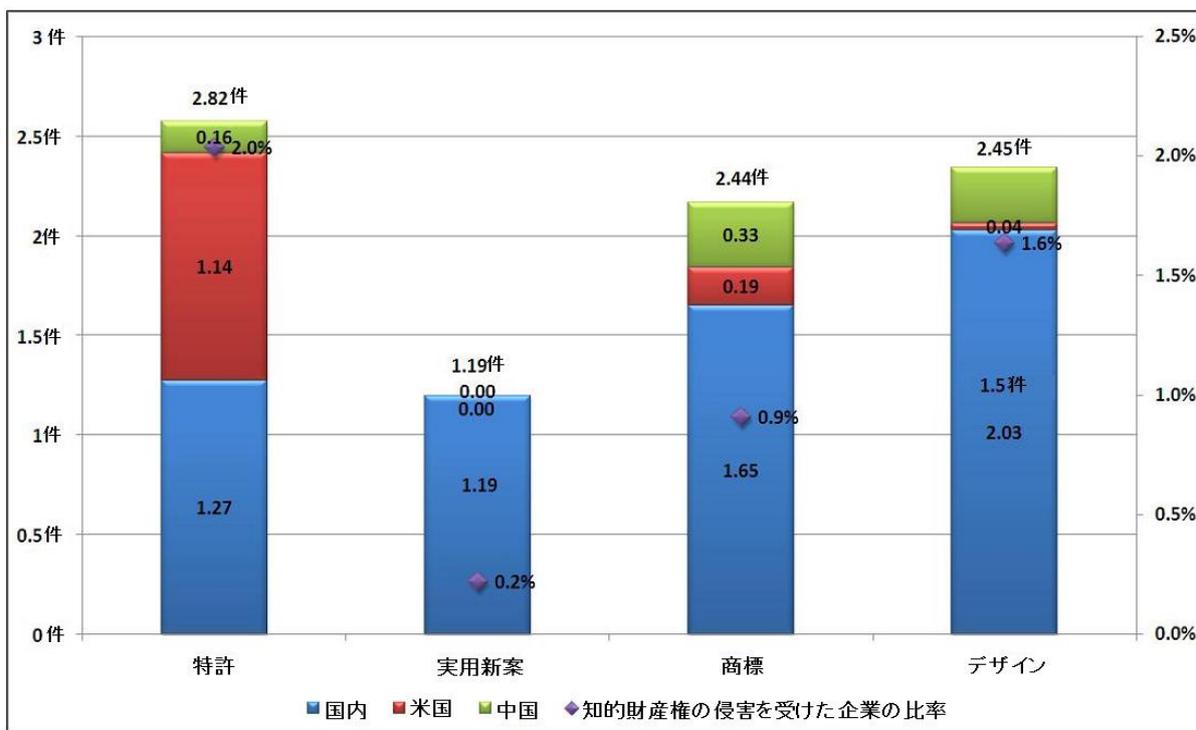


[図 2.42]企業類型別の知的財産権侵害の被害比率

⁵⁴ 産業財産権(特許、実用新案、商標、デザイン)及び新知的財産権(半導体配置設計、地理的表示、営業秘密など)が含まれている。

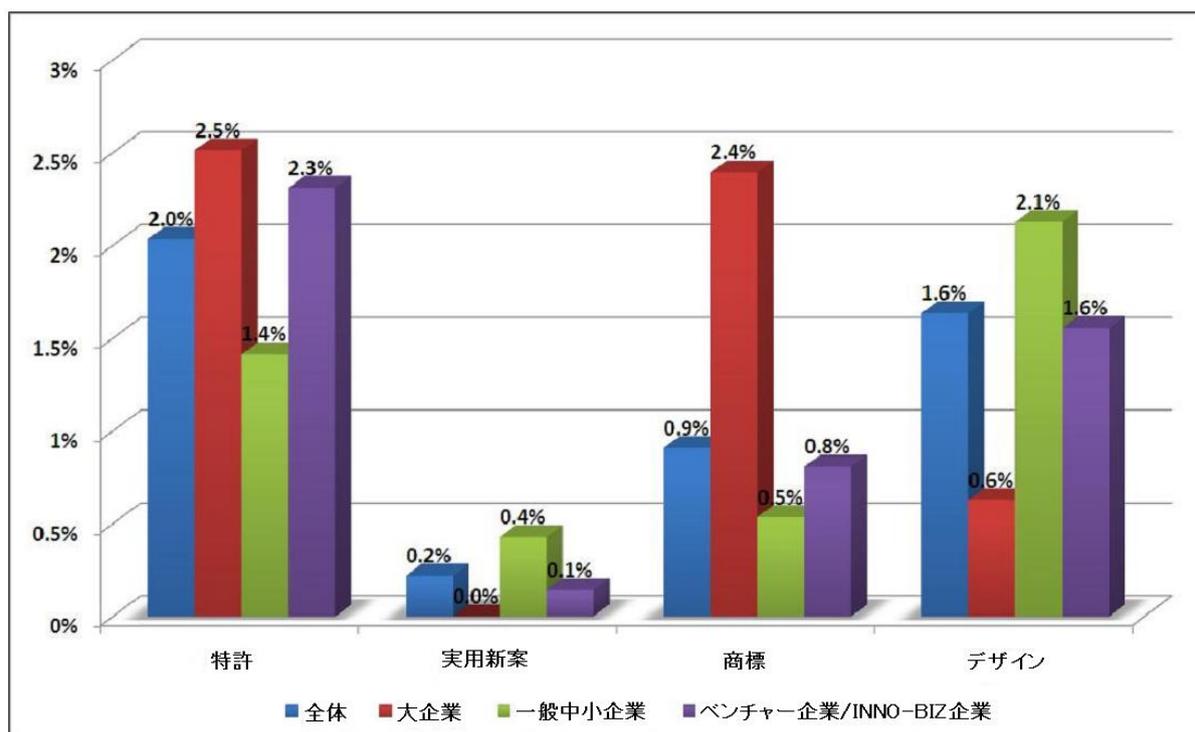


[図 2.43]出願件数別の知的財産権侵害の被害比率



[図 2.44]産業財産権類型別の侵害被害件数

産業財産権類型別に侵害被害を受けた企業の比重及びこれらの平均被害件数は[図 2.44]のとおりである。2011 年の 1 年間特許権侵害を受けた企業が全体の 2.0%(3.3%)で最も高く、その他に実用新案、商標、デザイン権の侵害を受けた企業の比率は各々 0.2%(0.8%)、0.9%(1.2%)、1.6%(2.8%)となっている。それぞれの平均侵害件数は特許が 2.82 件(2.22 件)、実用新案 1.19 件(1.43 件)、商標が 2.44 件(2.55 件)、デザインが 2.45 件(3.11 件)となっている。



[図 2.45]企業類型別の産業財産権侵害の被害比率

企業類型別では特許権の侵害を受けた比率は大企業 2.5%(3.5%)、一般中小企業 1.4%(3.0%)、ベンチャー企業 2.3%(3.4%)となっており、他企業類型に比べて大企業の比率が非常に高いことがわかる([図 2.45])。出願規模別では、10 件未満の場合 1.8%(2.2%)、10 件～20 件である企業の場合が 3.8%(4.2%)、21 件～60 件である企業の場合が 4.5%(8.1%)、61 件以上の多出願企業の場合 6.5%(4.8%)となっており、多出願企業であるほど特許侵害の被害比率が高いことがわかる([表 2.15])。

[表 2.15]出願規模別の特許侵害比率

	年平均 10 件未満	年平均 10～20 件	年平均 21～60 件	年平均 61 件以上
特許権 侵害比率	1.8%	3.8%	4.5%	6.5%

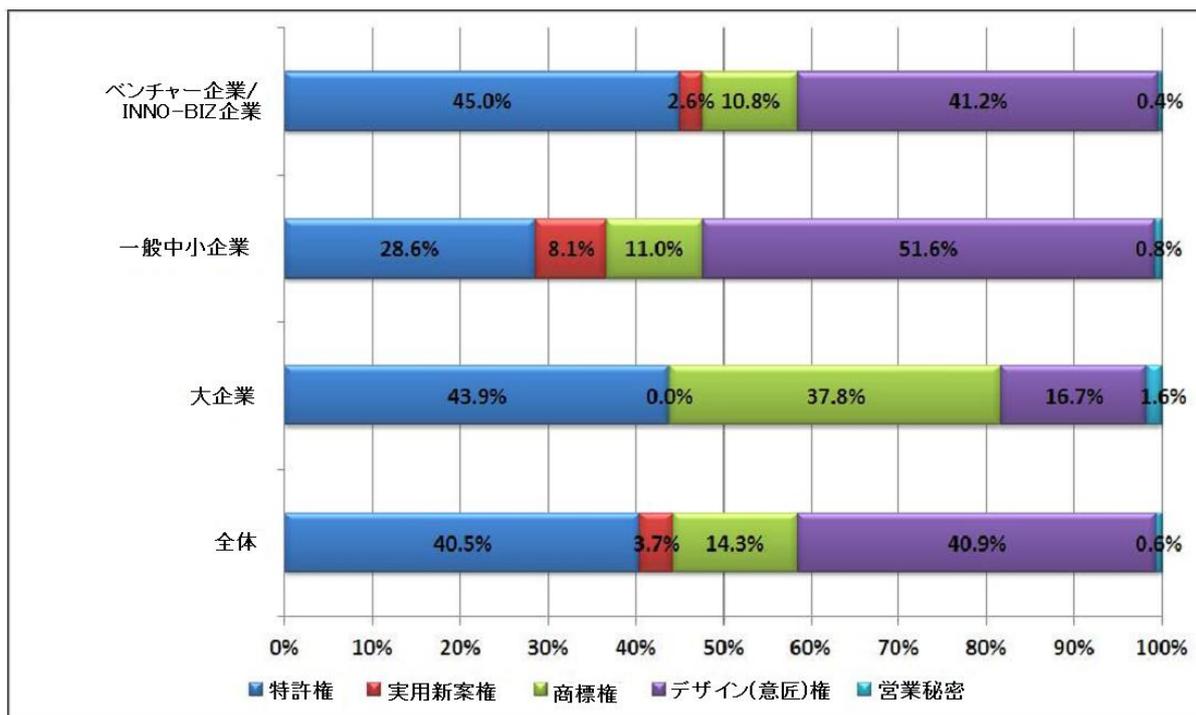
商標権もこれと類似した様子を見せているが、大企業が 2.4%(3.3%)で中小企業 0.5%(0.6%)、ベンチャー企業 0.8%(同一)よりその比率が高い。出願規模別の侵害被害比率を見ると、多出願企業であるほど被害比率が高いことがわかる([表 2.16])。

[表 2.16]出願規模別の商標権侵害比率

	年平均 10 件未満	年平均 10～20 件	年平均 21～60 件	年平均 61 件以上
商標権 侵害比率	0.4%	5.1%	5.0%	6.2%

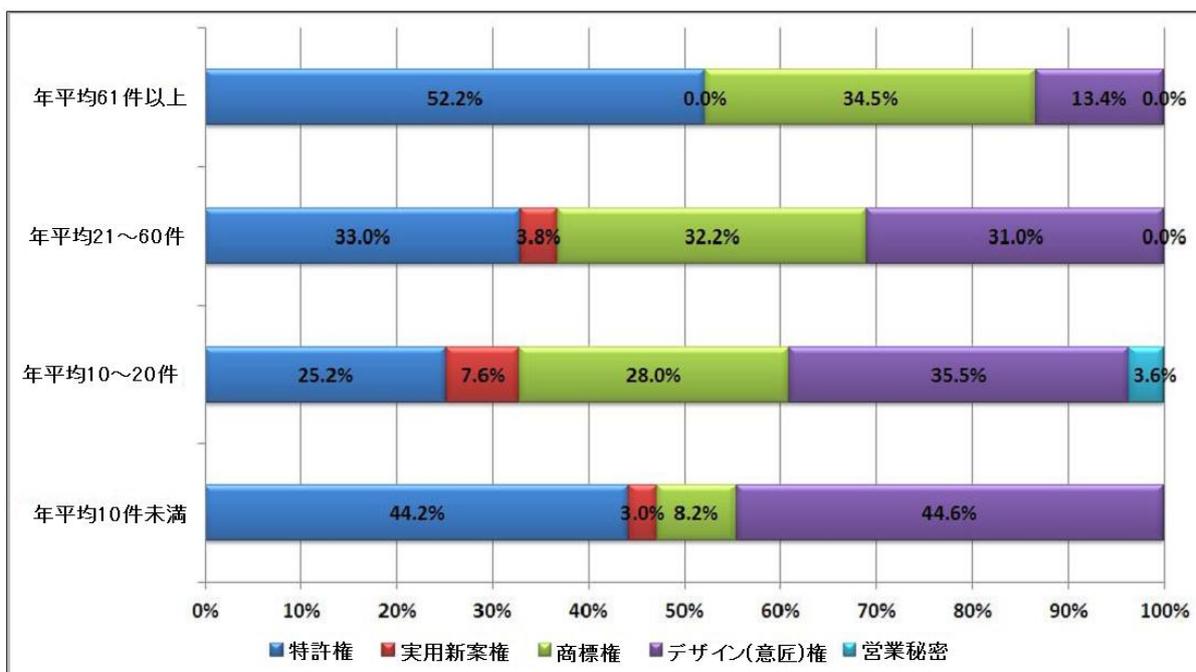
特許権の他に実用新案権とデザイン権の侵害を受けた比率は各々 0.4%(0.8%)と 2.1%(2.5%)と中小企業が最も高い。産業財産権の他に営業秘密侵害の被害を受けた企業は全体の 0.04%(0.2%)となっている。

次の[図 2.46]は知的財産権侵害被害における具体的な内容による権利類型の分布を示している。全体侵害事例の中で特許権が占める比重は 40.5%(44.5%)で最も高い。また、その後はデザイン権 40.9%(30.9%)、商標権 14.3%(15.5%)、実用新案権 3.7%(7.3%)と続いている。また、営業秘密侵害も全体の 0.6%(1.8%)を占めている。



[図 2.46]権利類型及び被害状況

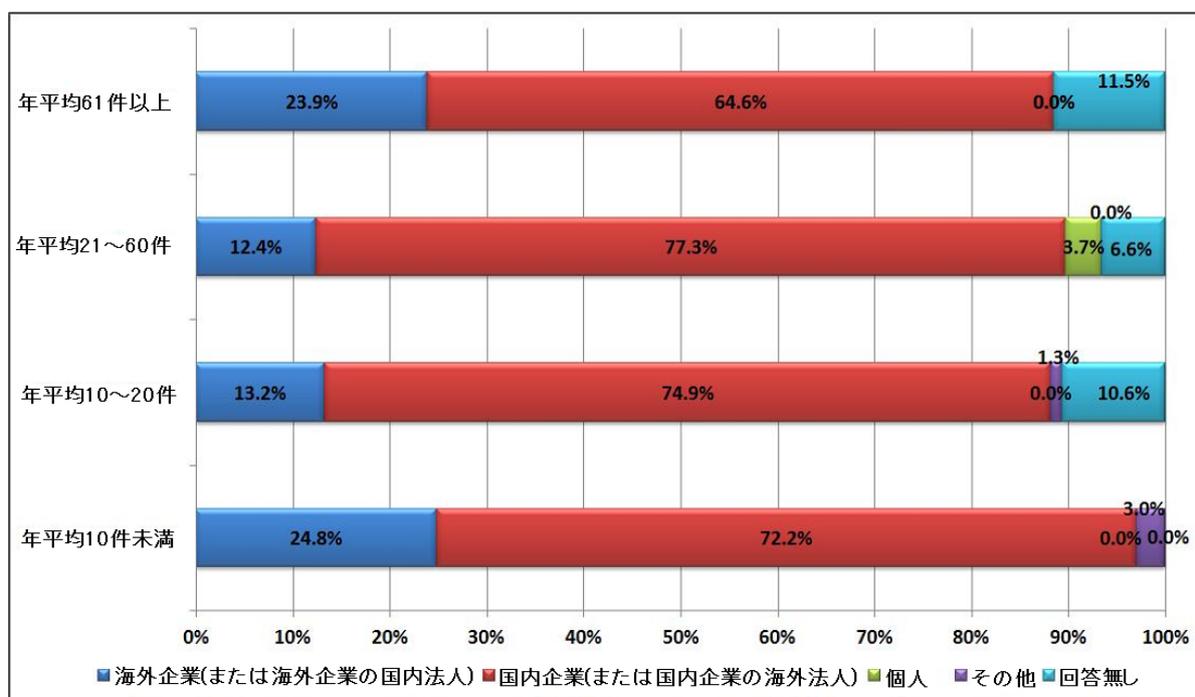
企業類型別では中小企業の場合全体侵害事例のうち 51.6%(33.3%)がデザイン権侵害で最も高い。一方、大企業とベンチャー企業の場合は全体侵害事例のうち各々 43.9%(42.9%)、45.0%(43.3%)が特許権侵害となっており、他権利類型より高い。



[図 2.47]出願規模別の産業財産権侵害の比重

産業財産権の出願規模別では、年平均 61 件以上出願した企業の場合は特許権の侵害比重が 52.2%(58.8%)で最も高く、商標権の侵害比重も 34.5%(29.4%)でその次となっている。出願件数が少なくなるほど商標権の侵害比重は減少する傾向にあり、それに対してデザインの侵害比重は増加する傾向にある([図 2.47])。

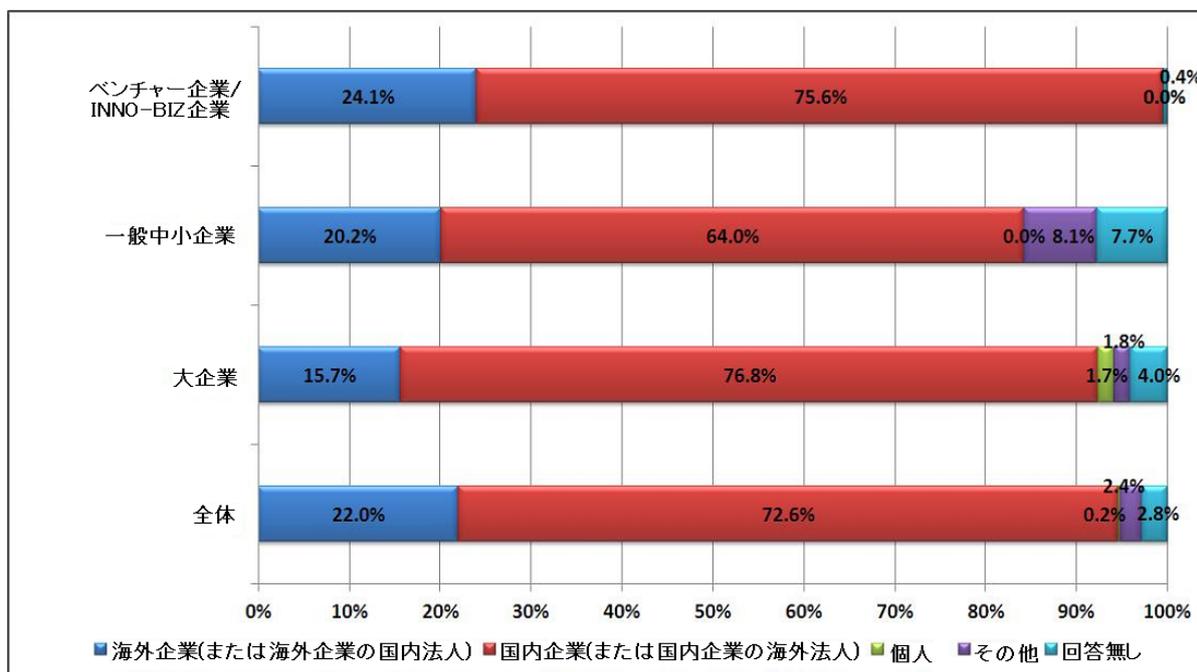
産業財産権の出願規模別では、侵害製品の製造者が国内企業である比率は年平均 10 件未満の企業と年平均 61 件以上の企業である場合比較的に低い。一方、侵害製品の製造者が海外企業である比率は同一グループ(出願規模が年平均 10 件未満の企業と年平均 61 件以上の企業)でむしろ高いことがわかった([図 2.48])。



[図 2.48]産業財産権出願規模別の侵害製品製造者の類型別比率

知的財産権の侵害被害の具体的な内容のうち侵害製品製造者の分布は次のとおりである。全体被害事例のうち 72.6%(80.9%)は国内企業であり、22.0%(14.5%)は海外企業となっている。また、個人の場合も全体の 0.2%(0.0%)となっている。大企業、一般中小企業、ベンチャー企業はいずれも侵害事例のうち侵害製品の製造者が国内企業である比率が各々 76.8%(68.6%)、64.0%(86.7%)、75.6%(86.7%)で製造者が海外企業

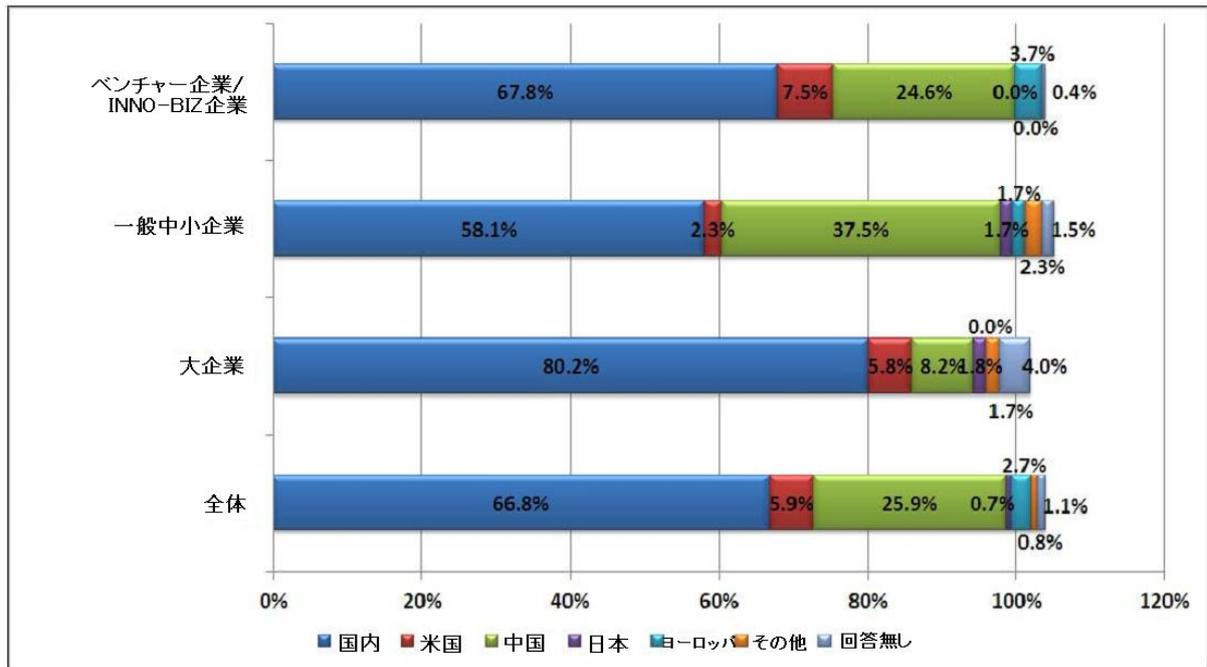
または個人である場合に比べて高く、企業類型別では大差はないことがわかる([図 2.49])。



[図 2.49]侵害製品製造者別の被害状況

注. 複数回答

侵害被害の具体的な内容のうち侵害製品製造地域の分布は[図 2.50]のとおりである。侵害製品の製造地域が国内である場合は全体の 66.8%(79.1%)で最も高い。また、製造地域が中国である場合が 25.9%(14.5%)、米国である場合が 5.9%(3.6%)と続いている。

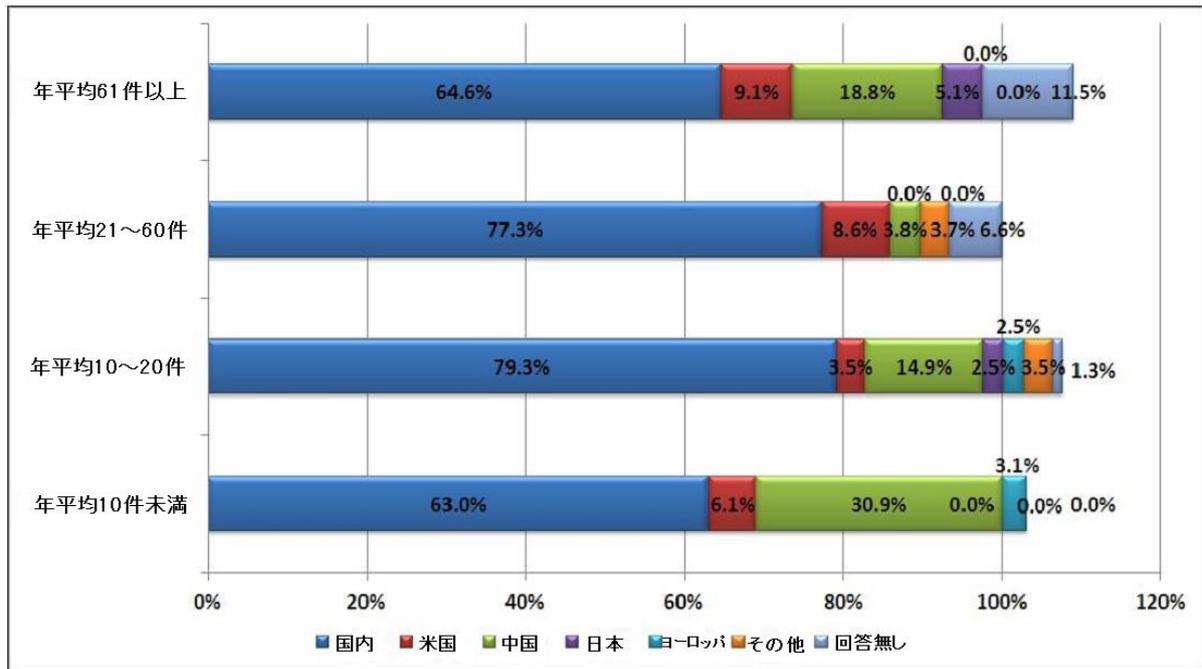


[図 2.50]侵害製品製造地域別の被害状況

注. 複数回答

企業類型別では侵害製品の製造地域が国内である比重が最も高いのは大企業であり、全体の 80.2%(74.3%)を占めている。また、製造地域が中国である場合は一般中小企業が 37.5%(33.3%)と大企業及びベンチャー企業より高い。

産業財産権の出願規模別では、年平均 10~20 件出願規模の企業の場合侵害製品の製造地域が国内である比重が 79.3%(77.1%)で最も高く、年平均 10 件未満企業の場合 63.0%(87.0%)と低いことがわかった。一方、中国が侵害製品の製造地域である場合は年平均 10 件未満の場合 30.9%(8.7%)で最も高く、年平均 21~60 件規模の場合 3.8%(4.5%)で最も低いことがわかった([図 2.51])。

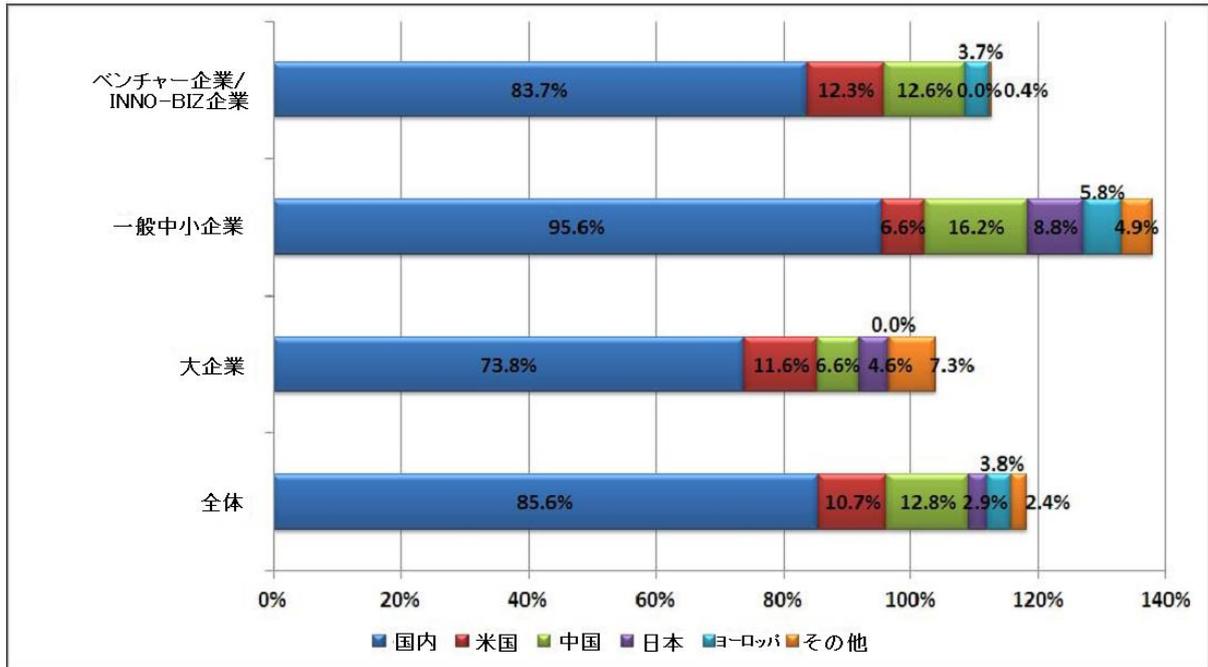


[図 2.51]産業財産権出願規模別の侵害製品製造地域の比率

知的財産権侵害被害の具体的な内容のうち侵害製品の流通地域の分布は[図 2.52]のとおりである。全体被害事例のうち 85.6%(86.4%)は侵害製品の流通地域が国内となっている。また、流通地域が中国と米国である比重も各々12.8%(10.0%)と 10.7%(9.1%)となっている。企業類型別では、流通地域が国内である比重は一般中小企業が95.6%(100.0%)となっており、他企業類型に比べて高く、大企業は73.8%(65.7%)で最も低い。全ての企業類型において侵害製品は国内で多く流通しており、海外で侵害製品が流通する場合は大企業の場合米国⁵⁵、一般中小企業の場合中国⁵⁶、ベンチャー企業の場合は中国と米国で流通する比率が比較的に高いことがわかった。

⁵⁵ 11.6%(14.3%)

⁵⁶ 16.2%(26.7%)

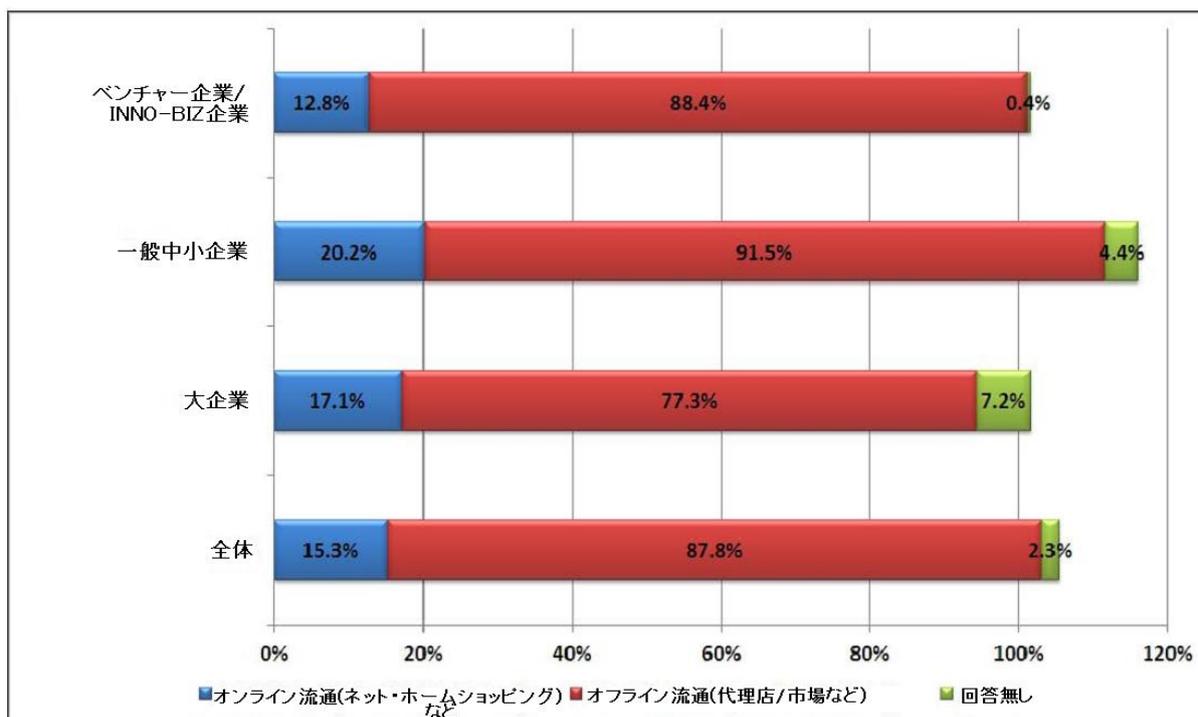


[図 2.52]侵害製品流通地域別の被害状況

注. 複数回答

産業財産権の出願件数による規模別では、侵害製品の流通地域が国内である場合は年平均 10～20 件規模の企業の場合が最も高い 89.1%(89.6%)となっており、年平均 61 件以上の多出願企業の場合はむしろ低い 56.3%となっている。流通地域が中国である比重は年平均 61 件以上の多出願企業の場合 14.1%(17.6%)で最も高く、米国である比重もまた年平均 61 件以上の多出願企業の場合に 15.7%(11.8%)で最も高い。

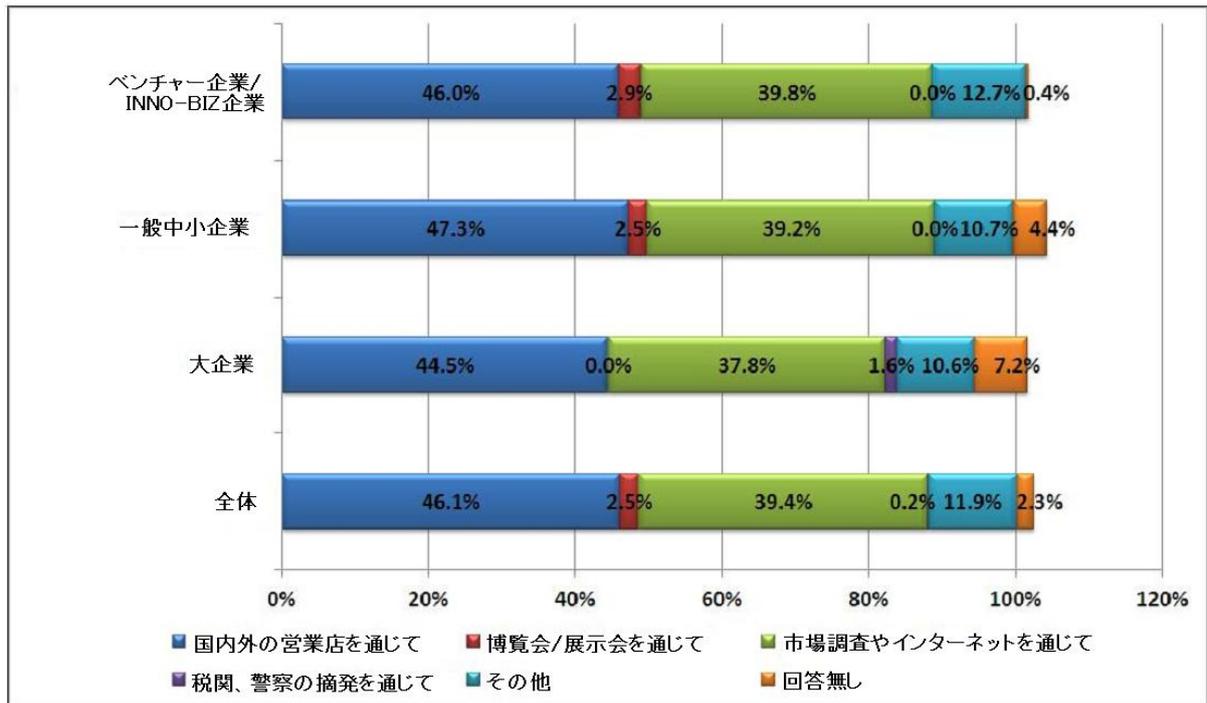
知的財産権侵害被害の具体的な内容のうち侵害製品流通タイプの分布は[図 2.53]のとおりである。全体被害事例の 87.8%(82.7%)は代理店及び市場などオフラインで流通しているものと見られる。インターネット及びホームショッピングなどオンラインで流通する比率は中小企業が 20.2%(26.7%)で他企業類型より高い。



[図 2.53]侵害製品の流通類型及び被害状況

注. 複数回答

知的財産権侵害被害の具体的な内容のうち侵害製品発見経路の分布は[図 2.54]のとおりである。全体被害事例のうち 46.1%(40.0%)の場合国内外の営業店を通じて被害事実を認知していることがわかった。市場調査やインターネットを通じた場合も 39.4%(40.9%)を占めている。国内外で営業店の多く構えている大企業の場合は営業店を通じて被害事実を認知する比率が 44.5%(40.0%)で最も高く、一般中小企業及びベンチャー企業の場合も営業店を通じて認知する場合が各々47.3%(73.3%)と 46.0%(31.7%)で相対的に高いことがわかる。



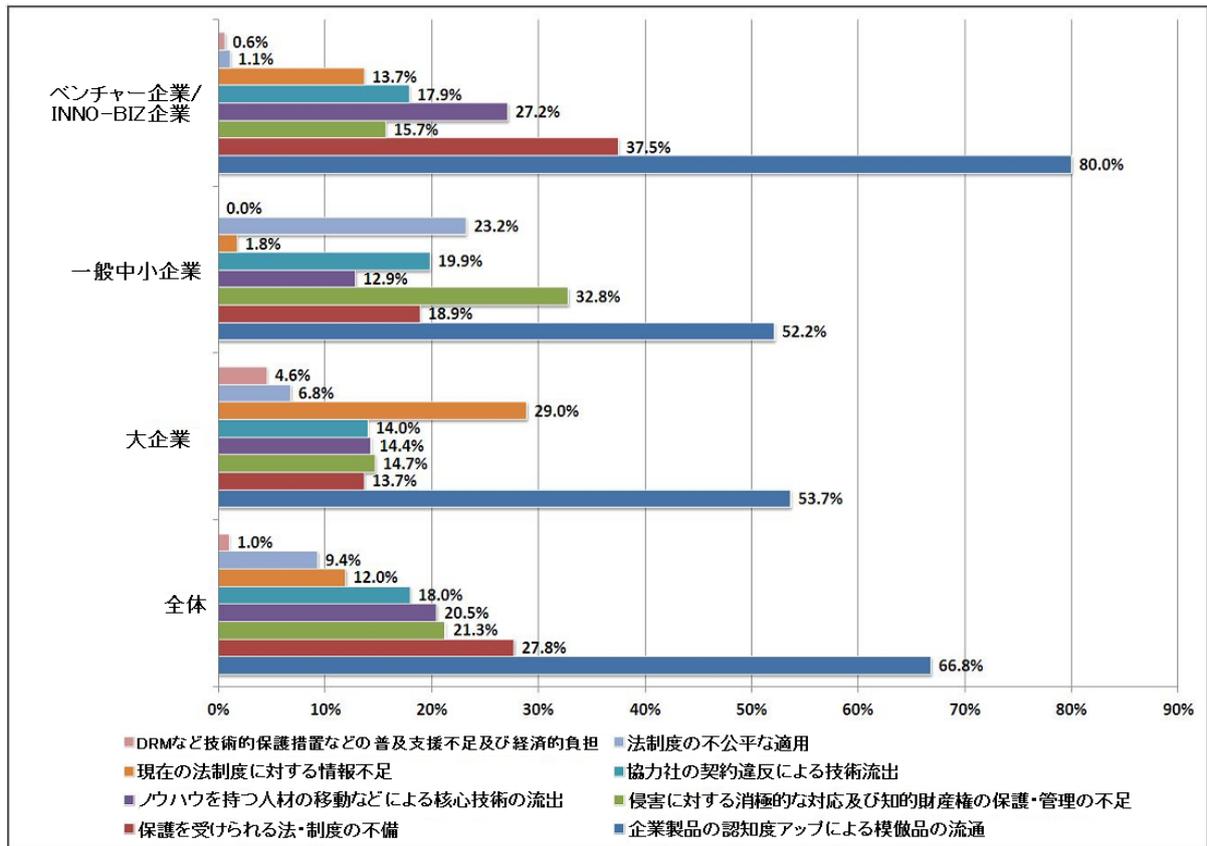
[図 2.54]侵害製品の発見経路別の被害状況

注. 複数回答

知的財産権侵害による被害が発生した原因は[図 2.55]のとおりである。「企業製品の認知度アップによる模倣品の流通」を原因として挙げた企業の比率は知的財産権侵害を受けた企業のうち 66.8%(56.4%)となっており、全ての企業類型で最も高いことがわかる。また、「保護を受けられる法・制度の不備」と「侵害に対する消極的な対応及び知的財産権の保護・管理の不足」を挙げた企業の比率も各々27.8%(33.7%)と21.3%(19.4%)と続いている。

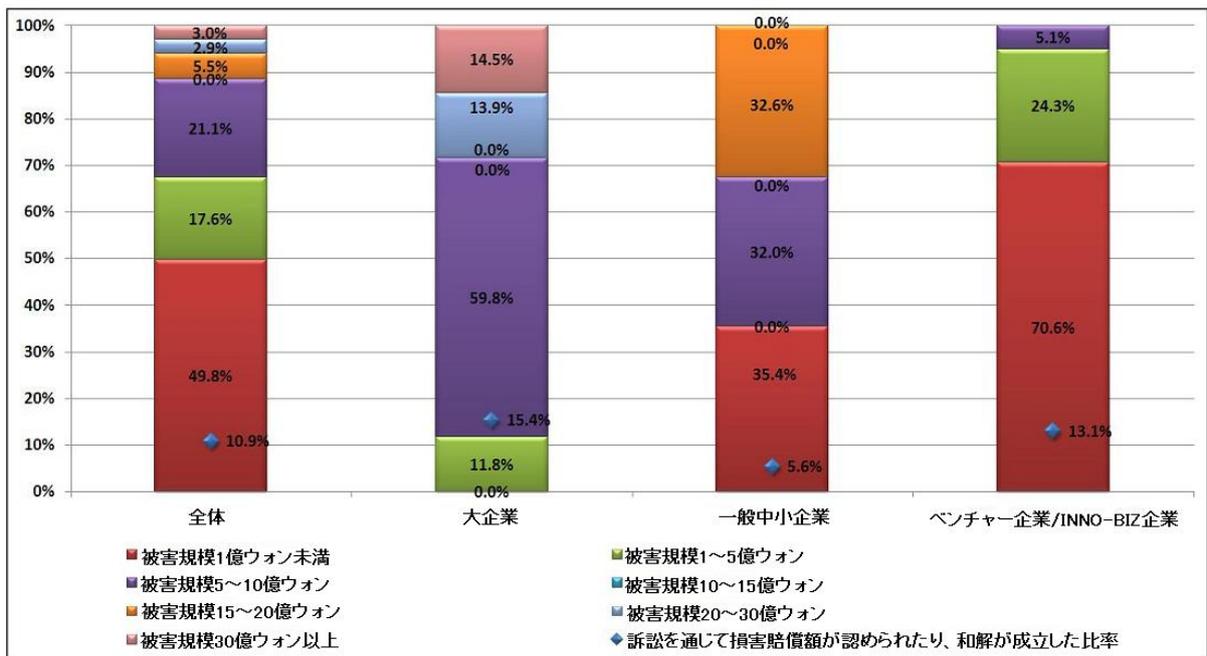
企業類型別では「企業製品の認知度アップによる模倣品の流通」を原因として挙げた比率を除けば、大企業の場合「現在法制度に対する情報不足」が 29.0%(17.1%)と二番目で高い比重を占めている。また、一般中小企業の場合、「侵害に対する消極的な対応及び知的財産権の保護・管理の不足」、ベンチャー企業の場合には「保護を受けられる法・制度の不備」が二番目に高い比重を占めた⁵⁷理由となっている。

⁵⁷ 一般中小企業の場合、該当理由が32.8%(12.2%)、ベンチャー企業の場合該当理由が37.5%(39.8%)を占めている。



[図 2.55]知的財産権侵害の被害が発生した主な原因

注. 複数回答



[図 2.56]損害賠償額または和解金の規模

2011年の1年間知的財産権の侵害を受けた企業の中で民事訴訟を通じて損害賠償額を認められたり、当事者間で和解が成立した比率は10.9%(15.3%)となっている([図 2.56])。大企業の場合は15.4%(23.2%)でベンチャー企業13.1%(14.9%)、一般中小企業5.6%(8.1%)より高い傾向となっている。これは中小企業とベンチャー企業の場合、知的財産権の侵害を受けても損害賠償額を認められたり、和解が成立した場合が大企業より相対的に低い可能性があることを意味する。

出願件数別では出願件数の多い企業ほど損害賠償額及び和解金がもらえる比率が高い。年平均21～60件出願企業の場合30.3%(18.7%)、61件以上企業の場合25.0%(20.1%)となっている([表 2.17])。

[表 2.17]産業財産権出願規模別の損害賠償金または被害金額発生企業の比率

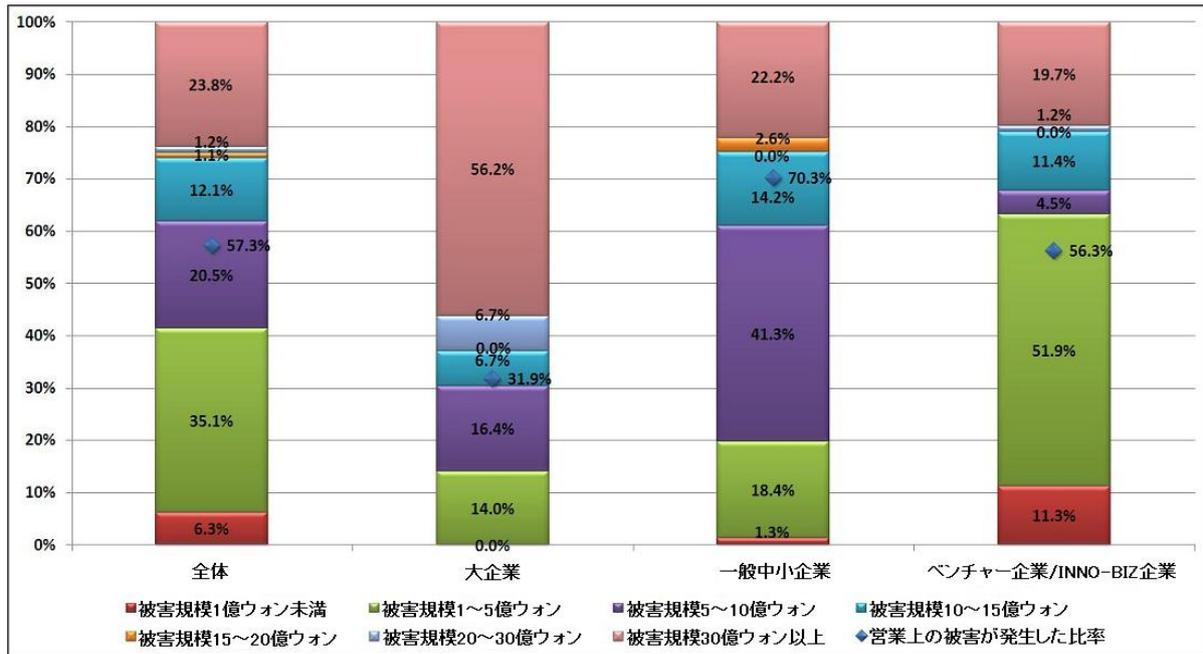
	年平均 10件未満	年平均 10～20件	年平均 21～60件	年平均 61件以上
損害賠償額または和解金発生比率	6.1%	20.8%	30.3%	25.0%

損害賠償額または和解金の規模は1億ウォン未満が49.8%(29.9%)で最も高い比率を占めているが、これは特にベンチャー企業の場合70.6%(34.4%)で他企業類型に比べて非常に高くなっている。一方、大企業の場合は損害賠償額または和解金の規模が5～10億ウォンの場合が59.8%(44.7%)で最も高い比率を占めており、企業類型別に差が見られる。

侵害製品が市場に流通することで売上高の減少や市場シェアの下落のような営業上の被害が実際発生した比率は知的財産権の侵害を受けた企業のうち57.3%(48.2%)を占めている([図 2.57])。この場合は一般中小企業が70.3%(79.6%)、ベンチャー企業が56.3%(41.2%)となっており、大企業31.9%(34.1%)より高く、損害賠償額または和解金の規模とは相反する結果となっている。産業財産権の出願規模による結果を見ると、10件未満企業のうち侵害を受けた企業の比率は62.7%(55.8%)で最も高い。但し、年平均10件以上企業に限って見ると、10～20件企業の場合は39.3%(41.3%)、21～60件企業の場合は47.1%(52.3%)、61件以上多出願企業の場合は52.6%(39.4%)となっており、出願件数が増加するほど被害金額の発生比率が増加する傾向にある([表 2.18])。

[表 2.18]産業財産権の出願規模別の実現された金額発生企業の比率

	年平均 10 件未満	年平均 10～20 件	年平均 21～60 件	年平均 61 件以上
実現された被害金額の発生比率	62.7%	39.3%	47.1%	52.6%



[図 2.57]実現された被害金額の規模

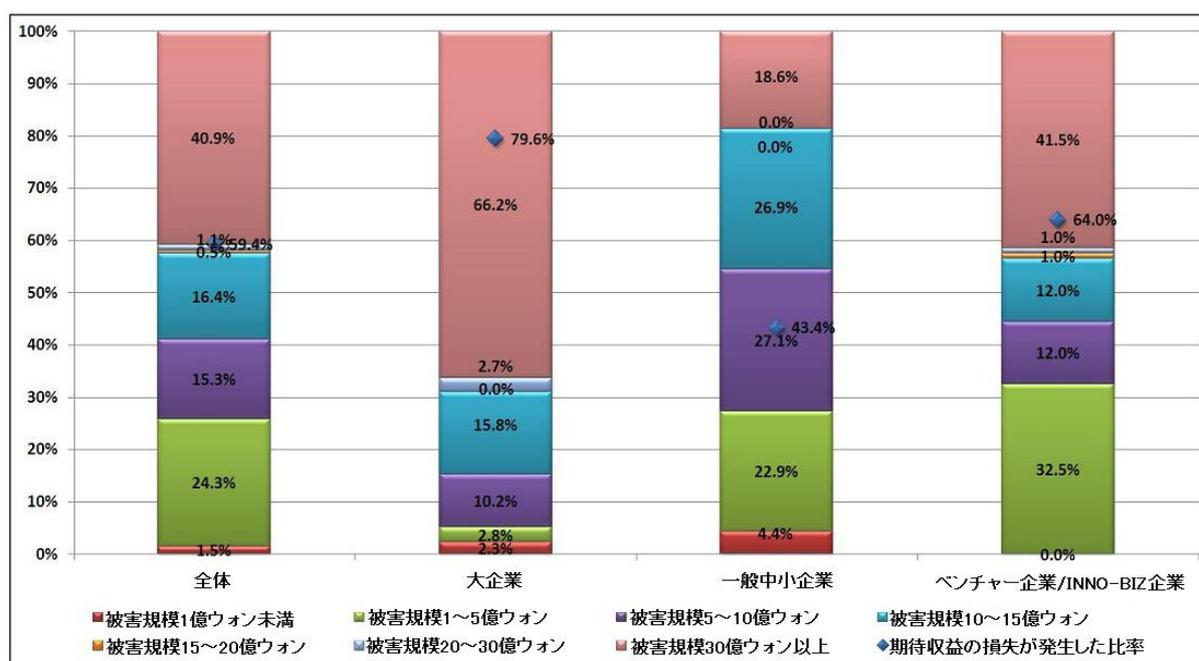
このような営業上の被害すなわち、実現された被害金額の規模は 1～5 億ウォン未満が全体の 35.1%(33.7%)で最も高い比重を占めており、30 億ウォン以上の場合も 23.8%(31.4%)を占めている。特に、大企業の場合 30 億ウォン以上の場合が 56.2%(63.7%)で一般中小企業 22.2%(21.7%)、ベンチャー企業 19.7%(27.3%)に比べて高い。企業類型別では、一般中小企業は 5～10 億ウォン未満の場合が 41.3%(15.4%)で最も高く、ベンチャー企業は 1～5 億ウォン未満の場合が 51.9%(43.0%)最も高い。

最後に売上高の減少など実質的な営業上の被害はないものの、今後新規市場参入、技術移転などを通じて得られたはずの期待収益の損失が予想されると答えた場合は知的財産権侵害被害企業の 59.4%(68.0%)となっている([図 2.58])。企業類型別では、大企業が 79.6%(78.2%)でベンチャー企業 64.0%(70.4%)、一般中小企業 43.4%(51.5%)

に比べて相対的に高い比重となっている。産業財産権の出願規模によっては多出願企業であるほど被害企業の比重が増加する傾向にある。すなわち、10件未満企業の場合は55.8%(64.5%)、10～20件企業の場合には57.7%(56.7%)、21～60件規模企業の場合は77.9%(85.1%)、61件以上の多出願企業の場合は100%(同一)となっている([表2.19])。

[表 2.19]産業財産権出願規模別の未実現被害金額が発生した企業の比率

	年平均 10件未満	年平均 10～20件	年平均 21～60件	年平均 61件以上
未実現被害金額の発生比率	55.8%	57.7%	77.9%	100%



[図 2.58]未実現被害金額の規模

企業が認知している未実現被害金額の規模は30億ウォン以上が40.9%(42.4%)で最も大きな比重を占めており、これは特に大企業での比重が66.2%(59.0%)と高く、ベンチャー企業の場合も41.5%(37.0%)と高い。一般中小企業の場合は5～10億ウォン未満が27.1%(23.8%)で最も高い。

2011年の1年間全体侵害被害を推定した規模は次の[表 2.20]のとおりである。損害賠償額(和解金)及び実現された被害金額は各々416億ウォン(788億ウォン)、7,623億ウォン(1兆703億ウォン)となっており、被害企業平均は各々4億8千万ウォン(6億6千万ウォン)、16億7千万ウォン(28億5千万ウォン)となっている。期待収益の損失金は4兆4,351億ウォン(5兆532億ウォン)となっており、被害企業平均は93億7千万ウォン(95億3千万ウォン)となっている。

[表 2.20]全体侵害被害規模の推定

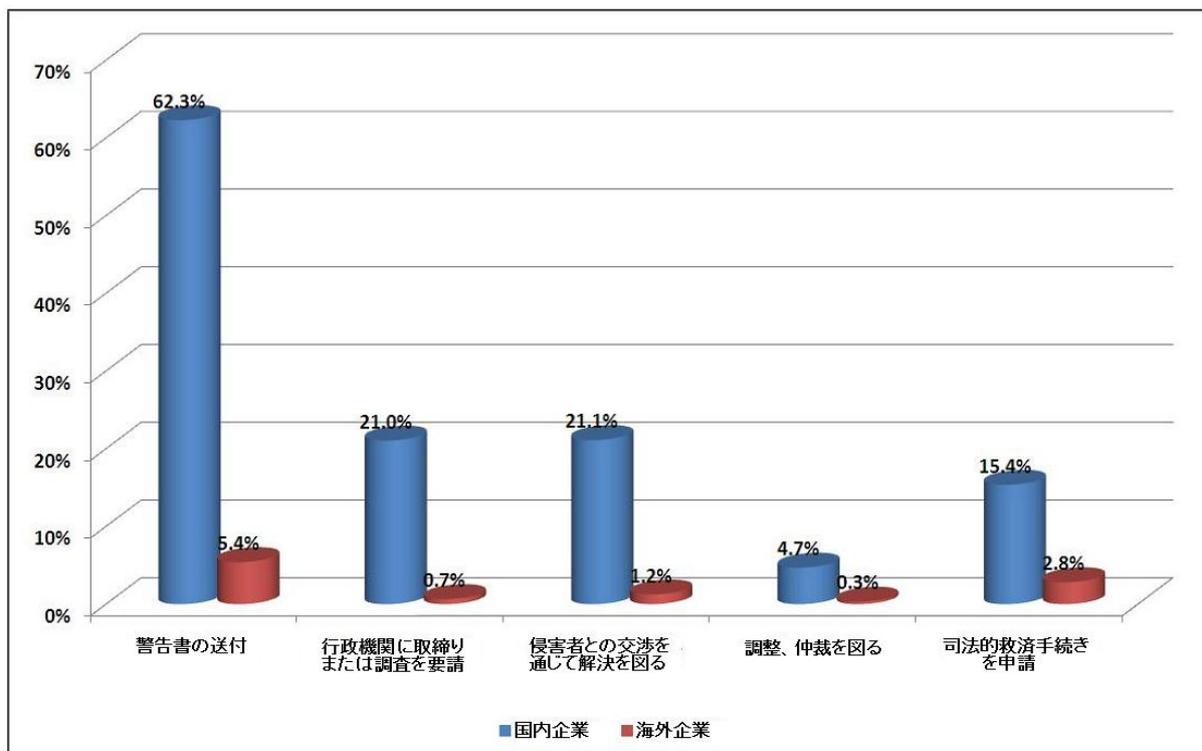
区分	企業数 ⁵⁸	被害金額(2011年)(億ウォン)	
		合計	企業の平均被害金額 ⁵⁹
損害賠償額(和解金)	87	416	4.8
実現された被害金額	457	7,623	16.7
期待収益の損失金	473	44,351	93.7

⁵⁸ 母集団(企業18,418社)推定値である。

⁵⁹ 被害企業の平均被害金額である。

2.知的財産権侵害に対する事後対応

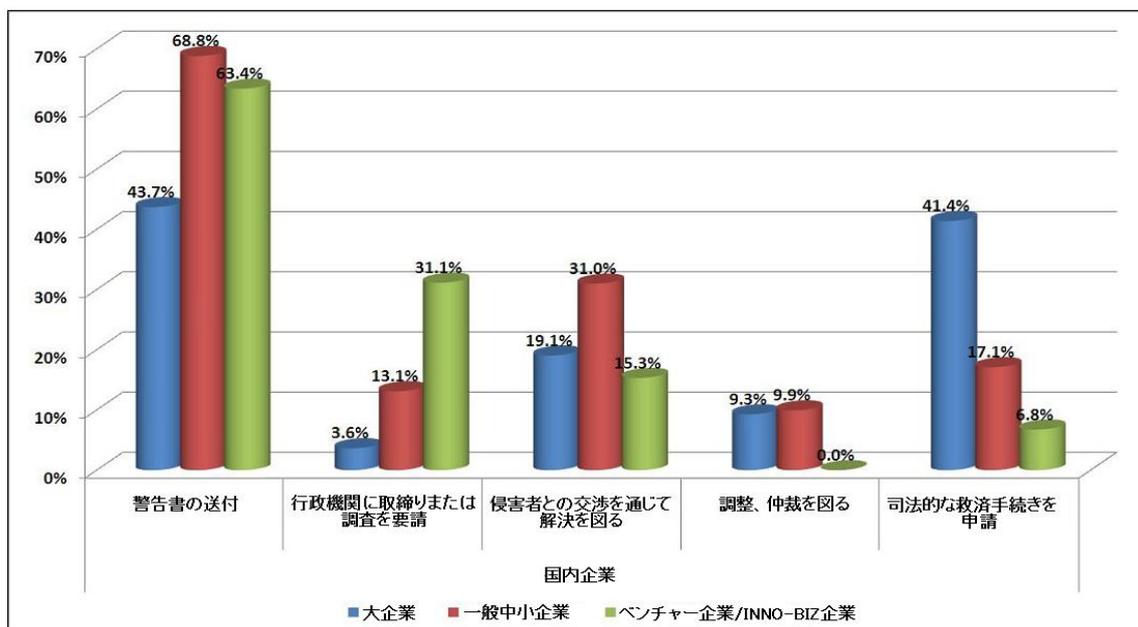
知的財産権侵害被害以後の対応活動として、2011年の1年間国内企業に警告書を送付した場合は知的財産権の侵害を受けた企業のうち62.3%(64.3%)で最も多い比重を占めている。侵害者との交渉を通じて解決を図った場合は21.1%(20.7%)、行政機関に取締りまたは調査を要請した場合は21.0%(15.6%)と続いている。また、調整や仲裁を図った場合は知的財産権侵害を受けた企業の4.7%(8.4%)に過ぎない。知的財産権を侵害した海外企業に対する対応活動も同じく警告書を送付した場合が知的財産権侵害を受けた企業の5.4%(7.3%)で最も多い比重を占めている([図 2.59])。



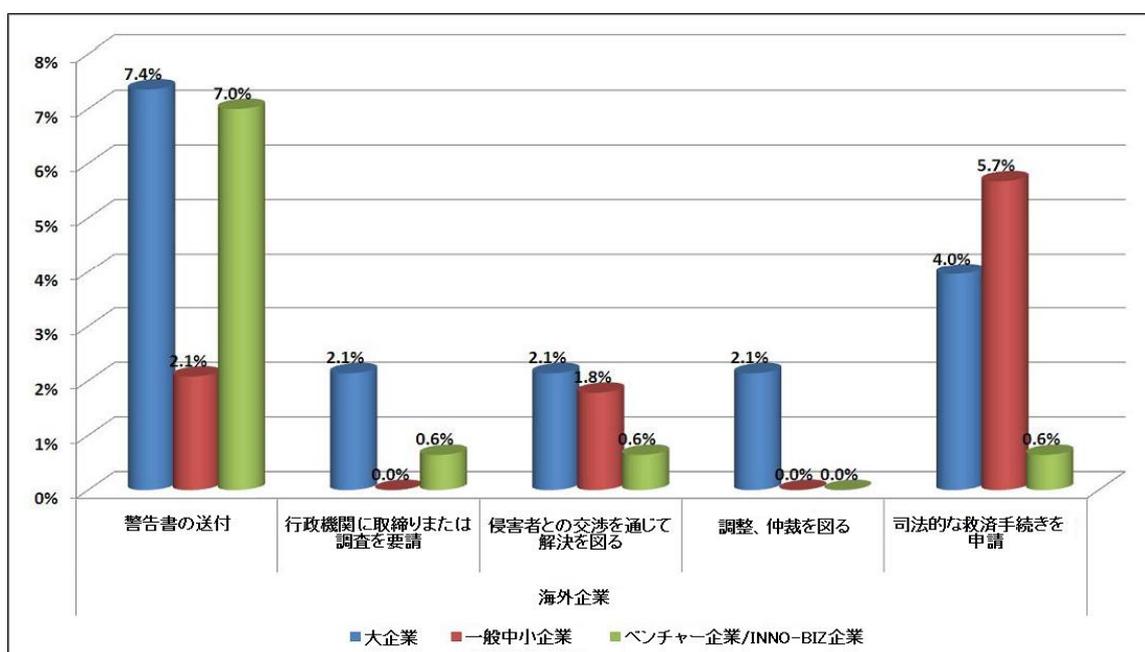
[図 2.59]知的財産権侵害に対する対応

企業類型別では、知的財産権侵害を受けた企業のうち国内企業に警告書を送付した比率は大企業が43.7%(50.3%)になっていることに対し、一般中小企業が68.8%(73.0%)となっており、中小企業の方が高いことがわかる([図 2.60])。一方、海外企業に警告書を送付した比率は大企業が7.4%(10.8%)、一般中小企業が2.1%(14.7%)と相対的に大企業が高いことがわかる([図 2.61])。大企業の場合は相対的に海外企業に対する侵害対応に積極的な傾向が強く、一般中小企業の場合相対的に国内企業に対する

侵害対応に積極的な傾向が強いといえる。国内企業に対して行政機関に取締りまたは調査を要請した比率は知的財産権の侵害を受けたベンチャー企業の 31.1%(22.3%)となっており、他企業類型より高い。⁶⁰



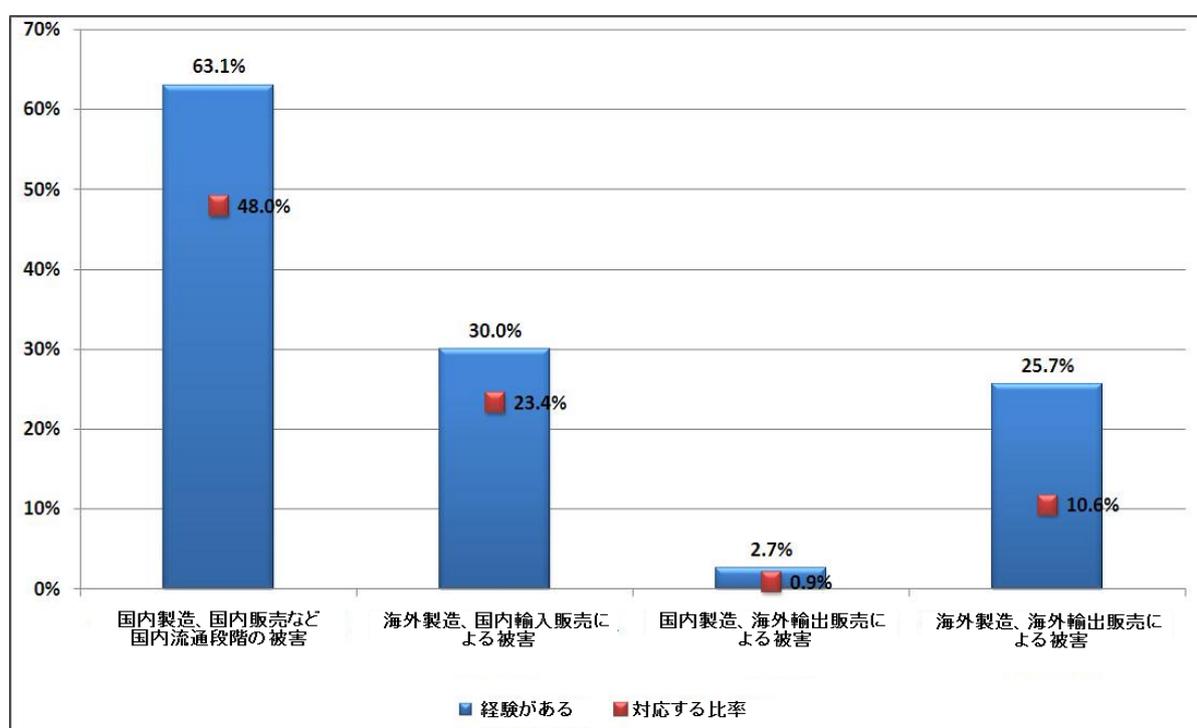
[図 2.60]企業類型別の国内企業に対する侵害対応方法



[図 2.61]企業類型別の海外企業に対する侵害対応方法

⁶⁰ 大企業の場合該当比率は3.6%(3.7%)、一般中小企業の場合該当比率は13.1%(12.2%)となっている。

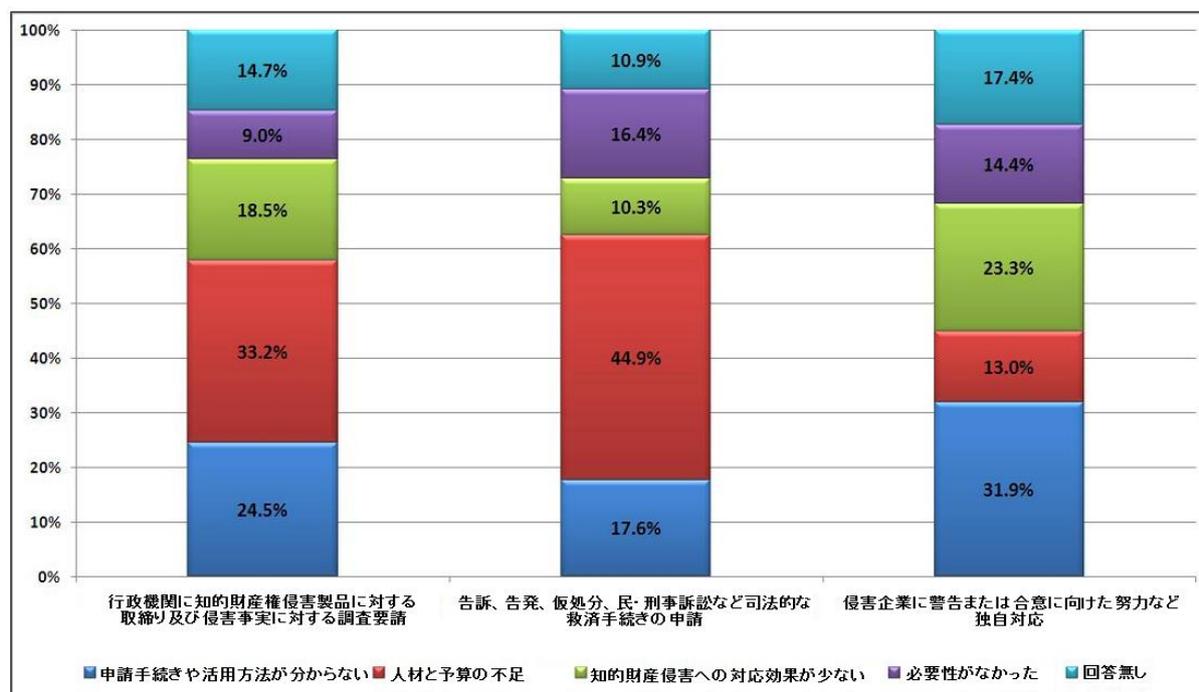
一方、知的財産権侵害を受けた企業の中で国内製造、国内販売など国内流通段階で被害を受けた企業の比率は 63.1%(76.0%)となっており、国内流通段階で被害を受けた企業の中で対応する企業の比率は 48.0%(63.9%)となっている([図 2.62])。その他に海外製造、国内輸入販売によって被害を受けた場合は 30.0%(15.5%)となっており、このうち対応する比率は 23.4%(10.0%)、国内製造、海外輸出販売による被害は 2.7%(3.5%)、このうち対応する比率は 0.9%(2.3%)となっている。また、海外製造、海外輸出販売によって被害を受けた比率は 25.7%(20.2%)、このうち対応する比率は 10.6%(8.7%)となっている。



[図 2.62]侵害製品の流通類型別の対応状況

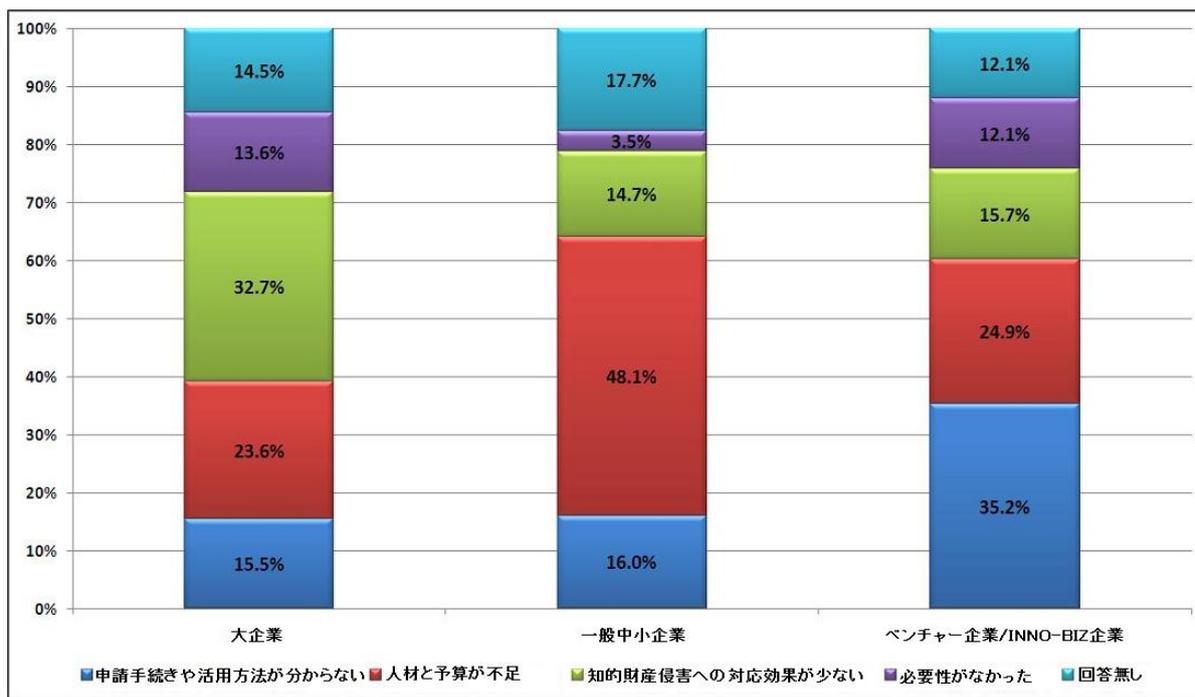
知的財産権侵害被害に対して対応活動を行っていないと答えた場合、各々の対応類型別では、まず「行政機関に取締り及び侵害事実に対する調査の要請」対応の場合には人材と予算不足を挙げた比率が 33.2%(30.4%)で最も高い。「司法的な救済手続きの申請」対応の場合にも同じく人材と予算不足によって該当対応を取らなかった比率が 44.9%(37.2%)を占めている。一方、「侵害企業に警告または合意に向けた努力など独自対応」方法を対応活動として取り入れなかった理由は申請手続きや活用方法が

わからなかったためであるという答えが 31.9%(34.5%)を占め、このような対応方法に対する広報及び教育が必要と判断される([図 2.63])。



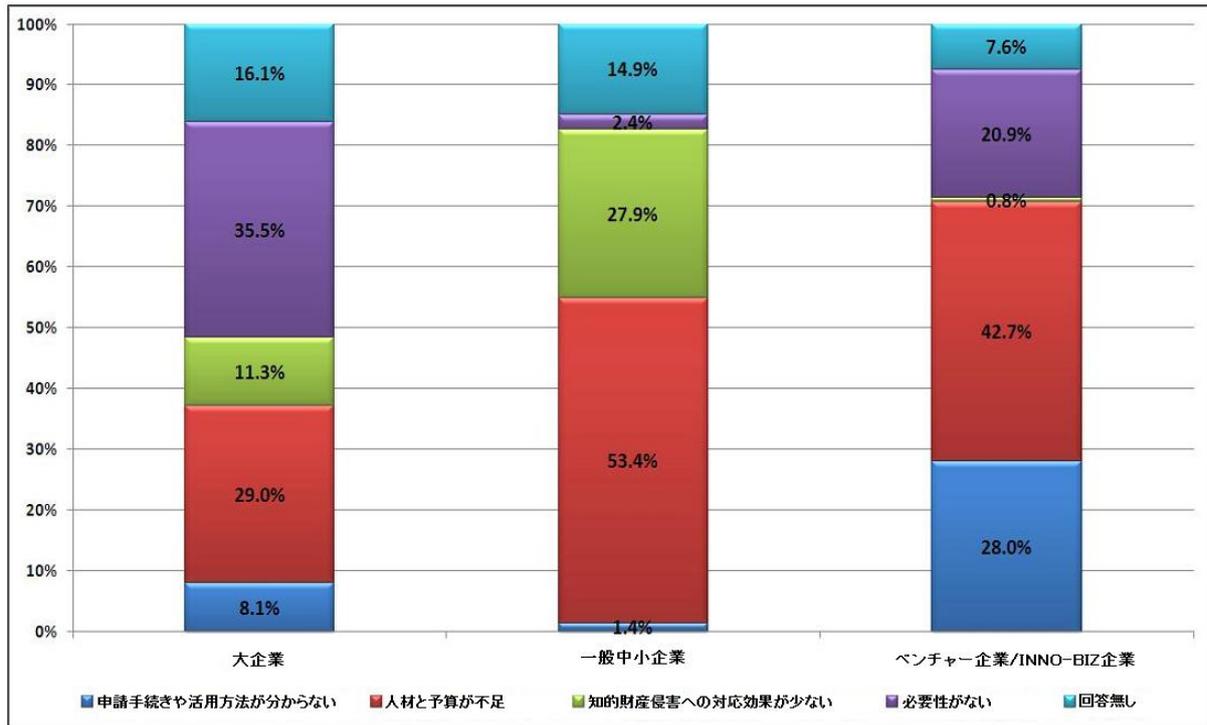
[図 2.63]対応活動を展開しない場合の理由

各々の対応類型によって企業類型別で見ると、政策的な示唆が得られる。まず、「行政機関に取締り及び侵害事実に対する調査要請」対応の場合、大企業は知的財産侵害対応効果が少ないためにこのような対応活動を展開しないと答えた比率が 32.7%(20.8%)となっており、最も高い([図 2.64])。しかし、一方中小企業は人材と予算不足のためにこのような対応活動を展開しないと答えた比率が 48.1%(46.1%)となっており、ベンチャー企業は申請手続きや活用方法が分からないためと答えた比率が 35.2%(34.6%)で最も高く、企業類型別に対応活動を展開しない理由が一致していない。中小企業の場合、優れた技術またはアイデアは持っているものの規模自体が零細であるため専門担当人材や費用の側面から政府の支援が切実な状況であり、一方ベンチャー企業の場合は侵害対応手続きや活用方法などに対する情報を適切に提供するとともに広報及び教育プログラムを拡大する必要があると思われる。これは企業の深層調査でも確認されているが、侵害に対応する時に法的知識に対する専門的な情報の不足による困難が多く確認されているため、これに対する政策的な支援が求められる。



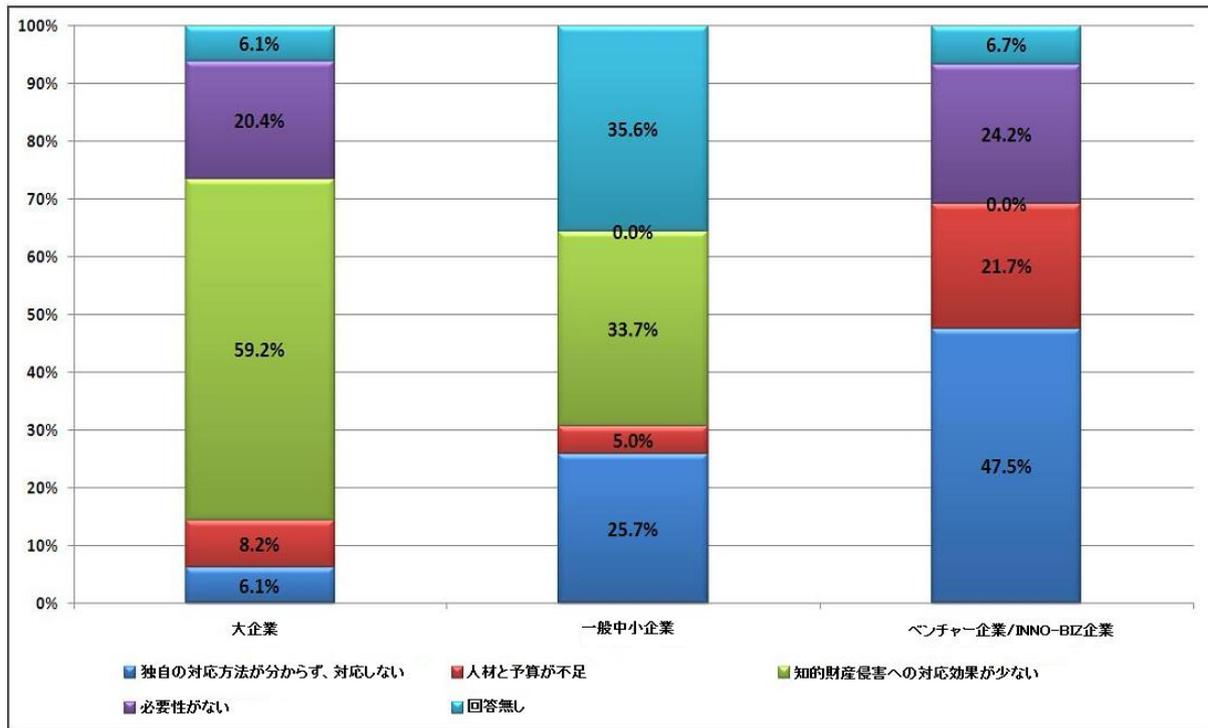
[図 2.64]企業類型別の対応活動(行政機関に知的財産権侵害製品に対する取締り及び侵害事実に対する調査要請)を展開しない理由

次に「告訴・告発、仮処分、民・刑事訴訟など司法的な手続きの申請」対応の場合必要性がなかったためにこのような対応活動を展開しないと答えた比率が大企業の場合 35.5%(33.1%)で最も高い([図 2.65])。しかし、一方の中小企業とベンチャー企業は人材と予算の不足を理由としてこのような対応活動を展開しないと答えた比率が各々 53.4%(70.4%)、42.7%(35.1%)で最も高い。司法的な救済手続きを申請する場合は、特に進行手続きに専門的な知識が求められると同時に期間が長いため、これによる人材と予算を考慮すると大企業に比べて中小企業やベンチャー企業の場合このような対応活動を展開するのは困難であろうと推測できる。特に、海外侵害の場合は各国の司法的な手続きに対する専門情報及び理解不足によって司法的な手続きを進行することが困難であることがわかった。



[図 2.65]企業類型別の対応活動(告訴・告発、仮処分、民・刑事訴訟など司法的な救済措置の申請)を展開しない理由

最後に「侵害企業に警告または合意に向けた努力など独自対応」の場合、知的財産侵害対応効果が少ないためにこのような対応活動は展開しないと答えた比率が大企業の場合 59.2%(13.4%)、中小企業の場合回答が無いものを除けば 33.7%(55.3%)で最も高い([図 2.66])。しかし、大企業の場合はこのような対応活動を通じて実質的な利益が少ないためであると判断されるが、一方中小企業の場合はこのような対応活動による費用及び時間の損失が大きいためであると思われる。ベンチャー企業は独自対応方法が分からず対応しなかった比率が 47.5%(34.4%)で最も高く、特にベンチャー企業の場合は侵害対応と関連して政府の政策的な公報及び教育支援などが切実に求められている。

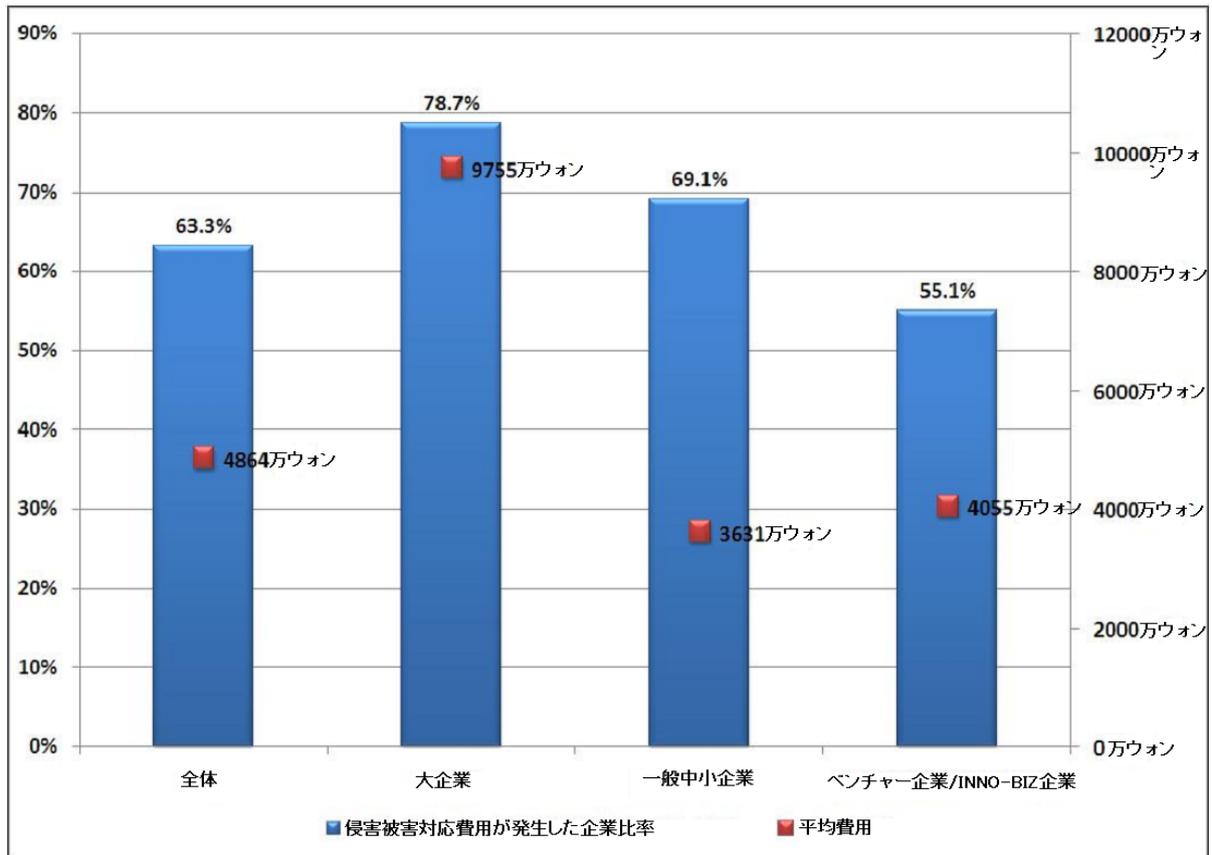


[図 2.66] 企業類型別の対応活動(侵害企業に警告または合意に向けた努力など独自対応)を展開しない理由

一方、2011年に知的財産権侵害を受けた企業のうち侵害対応費用⁶¹が発生した比率は63.3%(63.2%)を占めており、この企業たちの平均対応費用4,864万ウォン(1億3,996万ウォン)となっている([図 2.67])。

企業類型別では侵害対応費用が発生した比率は大企業が78.7%(87.9%)で最も高く、一般中小企業が69.1%(63.3%)、ベンチャー企業が55.1%(61.6%)と続いている。一般中小企業及びベンチャー企業の場合発生費用は各々3,631万ウォン(3,129万ウォン)、4,055万ウォン(1億6,896万ウォン)となっており、全体平均対応費用4,864万ウォン(1億3,996万ウォン)に比べて低い。一方、大企業の場合は平均対応費用が9,755万ウォン(1億5,078万ウォン)で非常に高い。

⁶¹ 警告書の送付から侵害訴訟完了時までにかかった費用を基準とする。(損害賠償額または和解金額は除く)



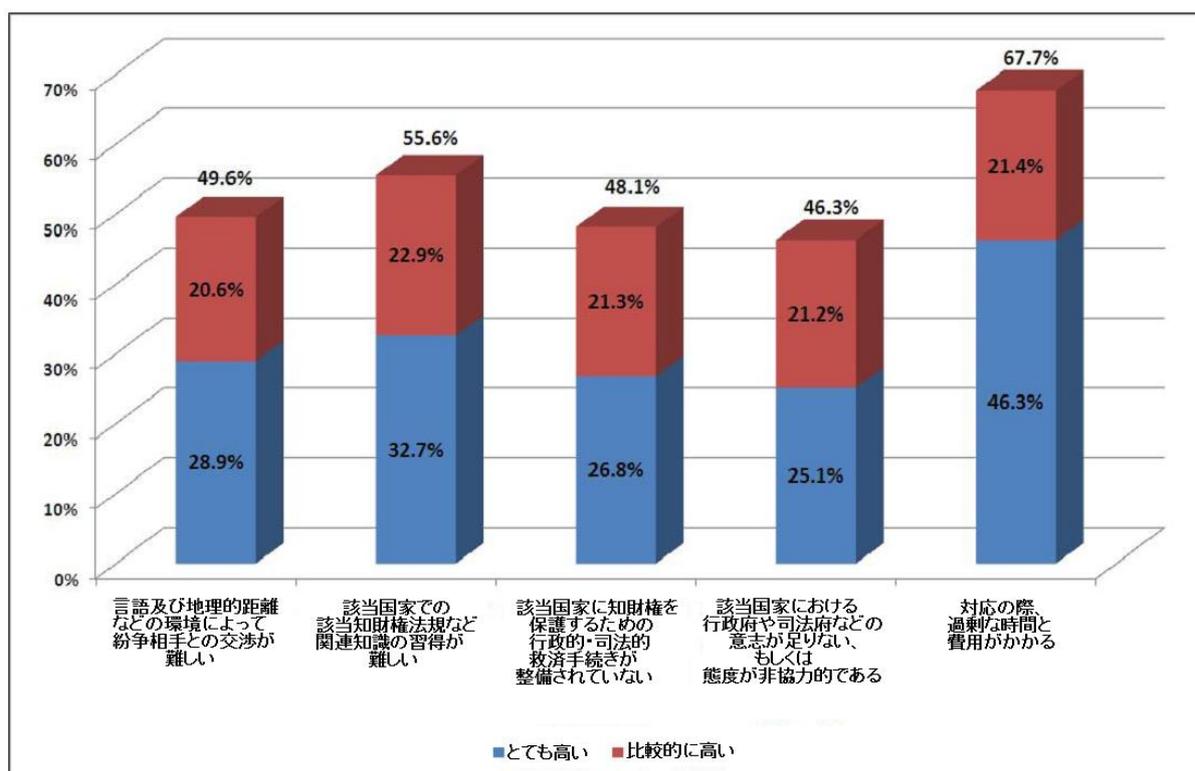
[図 2.67]知的財産権侵害対応費用

産業財産権の出願規模別では年平均 10 件未満規模の企業は 58.6%(47.6%)となっている。それに対して 10～20 件規模の企業の場合は 83.4%(85.1%)と侵害対応費用が発生した比率が最も高い。侵害発生企業の平均侵害対応費用を見ると、年平均 10 件未満規模の企業は平均 1,828 万ウォン(2,896 万ウォン)となっているのに対し、10 件以上の出願規模を持つ企業は平均侵害対応費用が高いことがわかった。⁶²

⁶² 侵害発生企業のうち産業財産の出願規模が年平均10～20件企業の平均侵害対応費用は1億3,810万ウォン(2億3,111万ウォン)、21～60件企業の平均侵害対応費用は1億2,802万ウォン(9,739万ウォン)、年平均61件以上企業の平均侵害対応費用は7,706万ウォン(1,767)となっている。

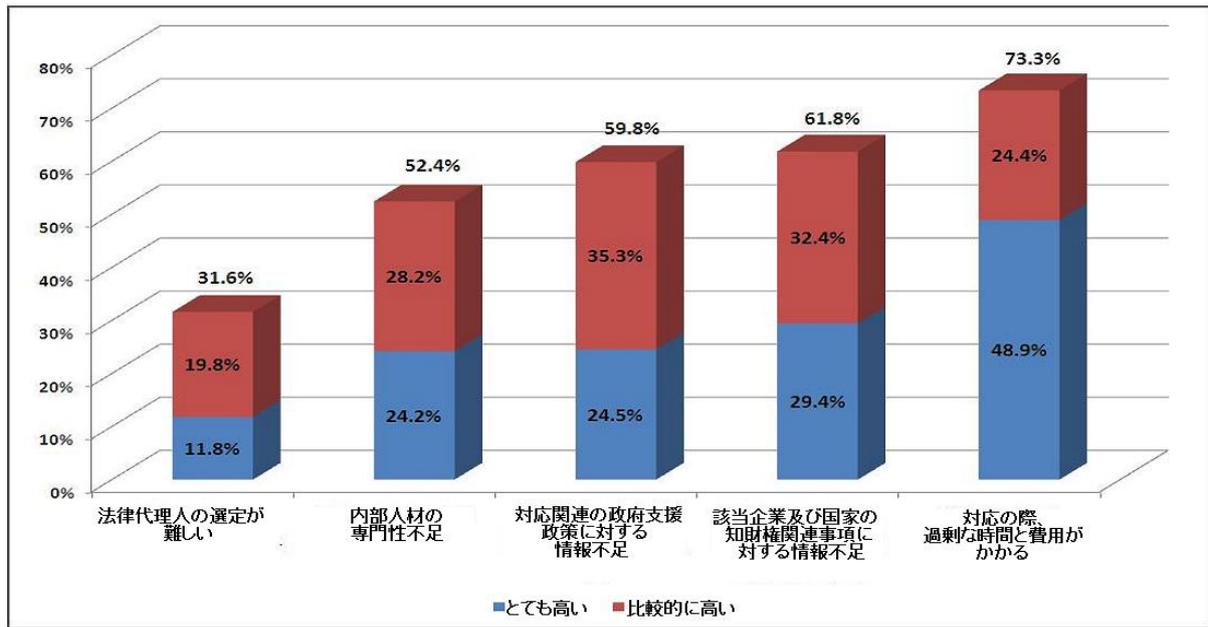
3.知的財産権紛争に関する難点及び必要な政策支援

知的財産権侵害への対応における難点として「対応の際過剰な時間と費用がかかる」と答えた企業は全体の 67.7%(72.4%)を占めている([図 2.68])。また、「該当国家での該当知財権法規など関連知識の習得が難しい」と答えた企業が 55.6%(59.2%)と続いている。侵害対応における難点を感じる程度は企業規模別に大きな差は見られない。



[図 2.68]知的財産権侵害の対応における難点

一方、他社の知的財産権を侵害したことで紛争が発生した時の対応における困難として、「対応の際過剰な時間と費用がかかる」と答えた企業の比率は 73.3%(75.7%)で、自社の知財権侵害への対応と同じく全企業類型の中で最も大きな比重を占めている([図 2.69])。また、「該当企業及び国家の知財権関連事項に対する情報不足」と答えた比率は 61.8%(62.0%)と続いている。



[図 2.69]他社知財権侵害による紛争時の対応における難点

最後に、知的財産権侵害に対応するため必要な政府政策として「迅速な権利救済のために国境措置対象の知的財産権範囲を拡大、侵害物品の国内流入シャットアウト」、「知的財産権の保護及び対応活動のための情報提供」、「知的財産権侵害に対応するための訴訟などの費用支援」が必要と答えた企業の比率は各々66.7%(68.9%)、65.5%(69.1%)、65.0%(68.2%)と比較的に同じ水準となっている([表 2.21])。

必要な政府政策と関連しては企業類型別に多少差が見られる。大企業の場合は「知的財産権の保護及び対応活動のための情報の提供」が必要と答えた比率が68.1%(65.9%)で最も高く、一般中小企業は「迅速な権利救済のために国境措置対象の知的財産権範囲を拡大、侵害物品の国内流入シャットアウト」が必要と答えた比重が64.6%(71.7%)で最も高い。ベンチャー企業の場合は「知的財産権侵害に対応するための訴訟などの費用支援」を挙げた比重が69.9%(70.8%)で最も高い。一方、「知的財産権侵害製品などに対する通報褒賞金額の増額」が必要と答えた比率は52.0%(53.6%)となっており、全ての企業類型において最低となっている。深層調査を通じた意見として政府レベルで法律的な諮問の費用支援などが必要であることがわかり、特許無効審判を通じても強力かつ迅速な効力が現れるように関連する法的・制度的措置が必要という意見も提示されている。

[表 2.21]知的財産権侵害に対応するために必要な政府政策

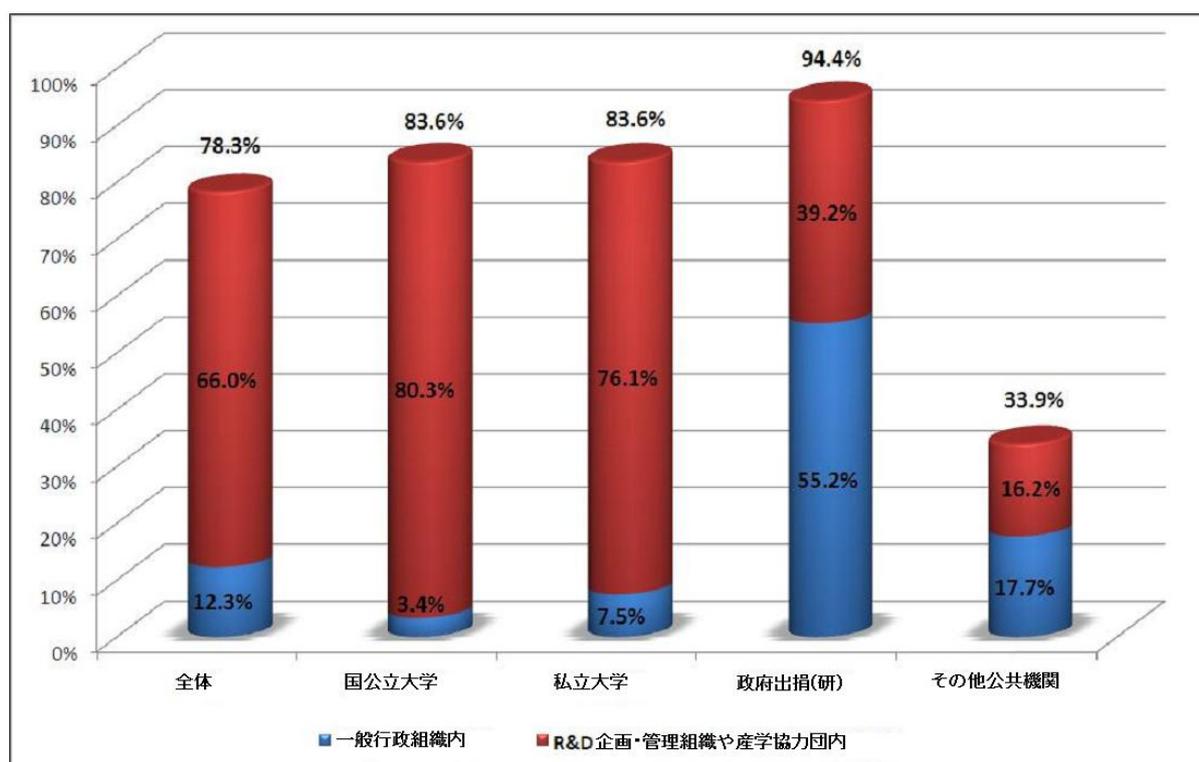
	全体	大企業	中小企業	ベンチャー企業
実効性のある行政的・司法的処罰措置の強化	64.9%	64.1%	63.7%	65.8%
迅速な権利救済のために国境措置対象の 知的財産権範囲を拡大、 侵害物品の国内流入シャットアウト	66.7%	64.1%	64.6%	68.6%
知 t 期財産権の保護及び対応活動のための情 報の提供	65.5%	68.1%	61.6%	67.2%
行政機関の知的財産権侵害製品に対する 取締り権限の強化	64.5%	63.7%	61.7%	66.4%
知的財産権侵害製品などに対する 通報褒賞金額の増額	52.0%	58.1%	46.4%	54.1%
知的財産権侵害に対応するための訴訟などの 費用支援	65.0%	68.0%	55.9%	69.9%

第3章 大学及び公共研究機関の知的財産活動

第1節 知的財産活動インフラ

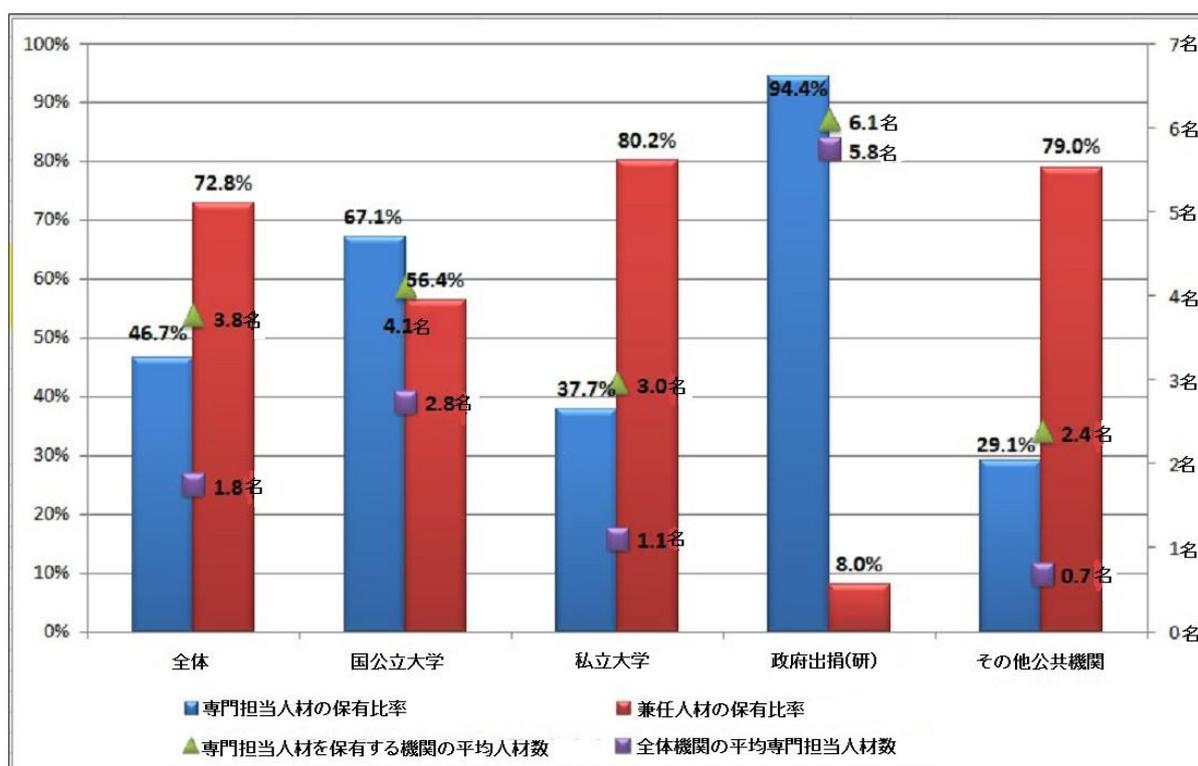
1.知的財産担当組織及び人材

知的財産担当組織を保有している国内の大学及び公共(研)の比率は 78.3%(80.0%)となっている([図 3.1])。これを細分化すると知的財産担当組織が一般行政組織の中に存在する比率が 12.3%、R&D 企画・管理組織や産学協力団内に存在する比率が 66.0%となっている。機関類型別では、政府出捐(研)と国公立大学の場合は各々全体の 94.4%と 83.6%が知的財産担当組織を保有していることがわかる。その他公共機関の場合 33.9%のみ知的財産担当組織を保有しており、最低となっている。



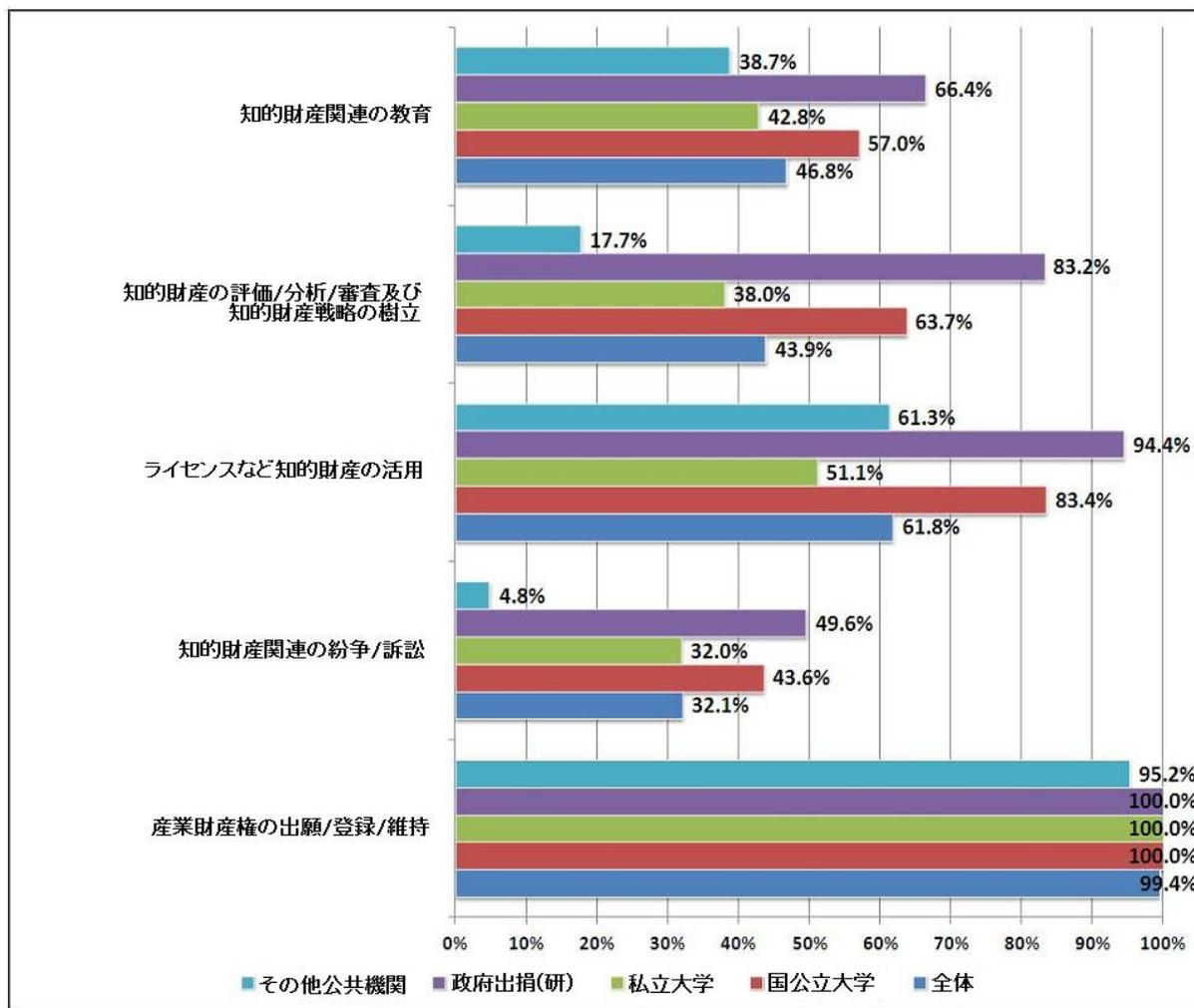
[図 3.1]知的財産担当組織の状況

国内大学及び公共(研)のうち知的財産関連の業務だけを専門的に担当する専門担当人材を保有している比率は 46.7%(47.8%)となっている([図 3.2])。機関類型別では政府出捐(研)の 94.4%(同一)が専門担当人材を保有しており、最も高いことがわかる。知的財産専門担当人材を保有している機関の平均専門担当人材の数は 3.8 名(同一)、機関全体平均専門担当人材の数は 1.8 名(同一)となっている。全体的に専門担当人材より兼任人材を保有する比率が高く、特に私立大学とその他公共機関の場合は専門担当人材より兼任人材を保有する機関の比率が相対的に高い。



[図 3.2]知的財産専門担当人材の保有状況

また、国内大学及び公共(研)は知的財産兼任人材を平均的に 1.17 名(1.18 名)保有しており、知的財産兼任人材を保有する機関の平均兼任の数は 1.60 名(1.63 名)となっている。機関類型別では、政府出捐(研)が保有する平均専門担当人材は 5.8 名で最も多く、国公立大学の平均専門担当人材の数も 2.8 名と続いている。

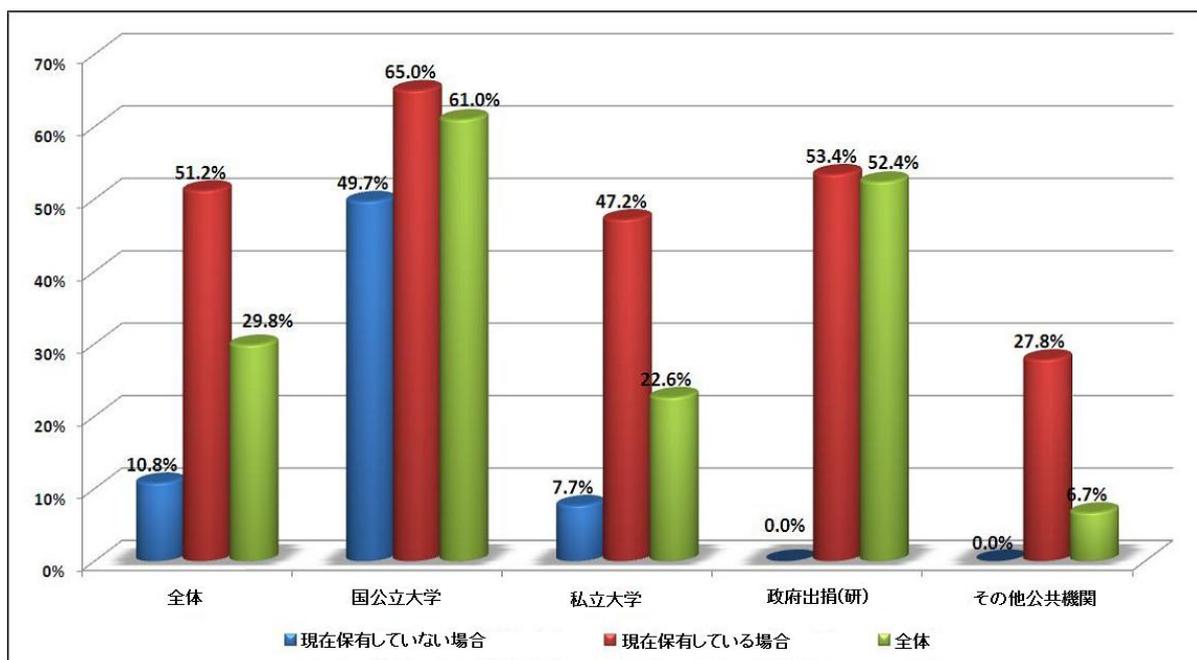


[図 3.3]知的財産担当者の主要業務

知的財産担当人材(兼任人材を含む)を 1 名以上保有している場合、該当人材が産業財産権の出願/登録/維持業務を担当する比率は 99.4%(99.3%)となっている。([図 3.3])。また、ライセンスなど知的財産活用関連業務と知的財産の評価/分析/審査など知的財産戦略の樹立を担当していると答えた比率は各々 61.8%(61.5%)と 43.9%(44.3%)となっている。知的財産関連紛争業務を担当する比率は 32.1%(同一)で最低となっている。

一方、国内大学及び公共(研)の 29.8%(29.9%)は今後知的財産専門担当人材を採用する計画を持っていると答えている([図 3.4])。特に、現在専門担当人材を保有していない場合の 10.8%が新規採用計画を持っており、現在保有している場合の 51.2%は追加採用計画があると答えている。機関類型別では、国公立大学の場合は現在保有していない場合の 49.7%が新規採用計画を持っており、現在保有している場合も 65.0%が追

加採用計画があると答えている。私立大学及び政府出捐(研)、その他公共機関の場合は現在保有していない場合は新規採用計画を持っている比率が非常に低く、一方現在保有している場合に限定すると追加採用計画を持っている比率は比較的が高い。このような事実は知的財産関連人材の採用において既存の人材を強化することで担当業務の品質向上及び集中を図っているものと判断できる。

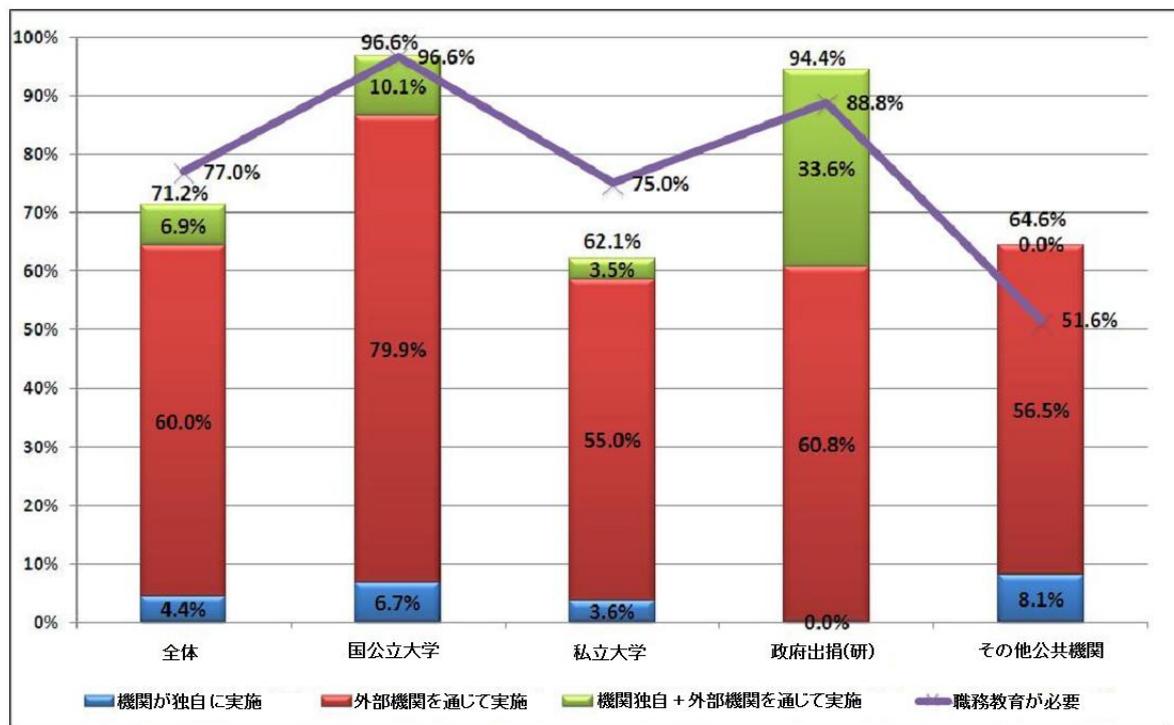


[図 3.4]知的財産担当人材の採用計画

2.知的財産担当人材に対する職務教育及び人件費・教育費

国内大学及び公共(研)のうち外部機関を通じて、または機関独自に知的財産担当人材に対して職務教育を行っている比率が各々60.0%と4.4%となっており、外部機関及び機関独自で同時に実施している比率は6.9%と占めている([図 3.5])。すなわち、全体の71.2%(72.3%)は知的財産担当人材に対する職務教育を実施しているといえる。機関類型別では、国公立大学の96.6%が担当人材の職務教育を行っており、政府出捐(研)の場合も94.4%が教育を行っており、他機関に比べてその比率が高い。私立大学及びその他公共(研)の各々37.9%と35.4%は知的財産担当人材に対する職務教育を全く行っていないことがわかる。

一方、全体の77.0%(77.7%)が知的財産担当人材に対する職務教育が必要またはとも必要であると答え、実際に行っている比率である71.2%より多少高い。特に、私立大学の場合は職務教育が必要と答えた比率(75.0%)と実際に実施している比率(62.1%)間の格差が相対的に大きい。従って、この部分に対する政策支援が必要と見られる。



[図 3.5]知的財産権担当人材に対する職務教育の現状及び必要性

注. 複数回答

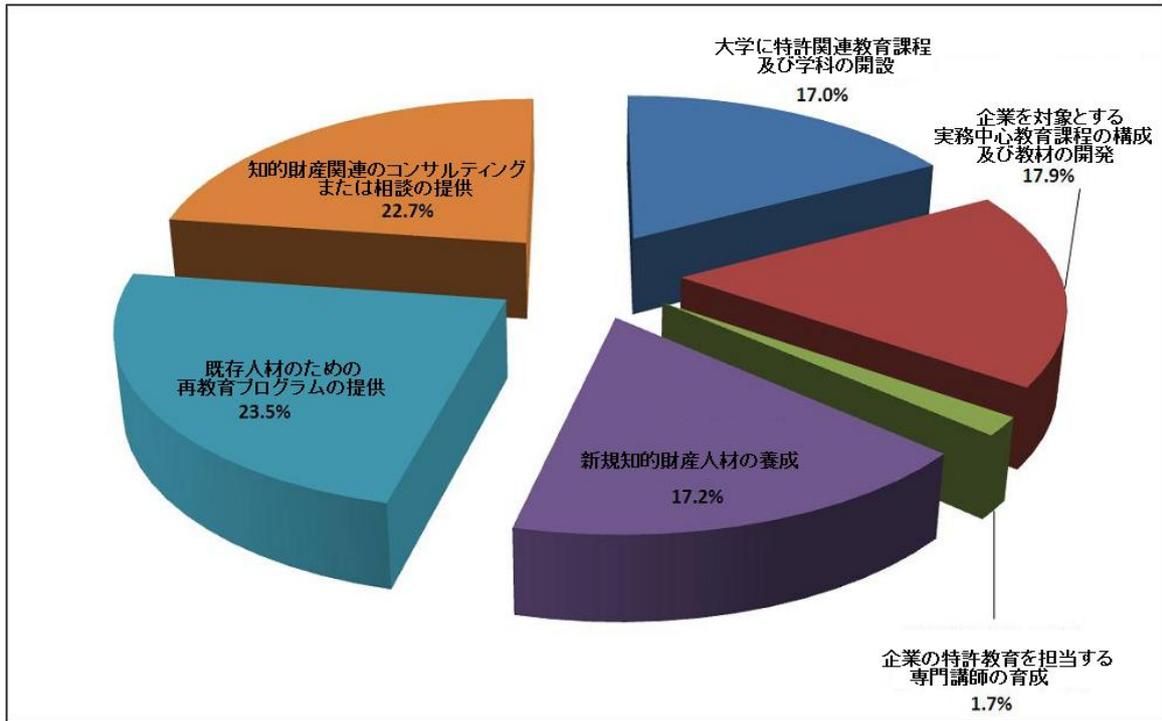
知的財産人材を対象とする職務教育の実施を希望する場合、主に取り扱うべき教育内容として全体の73.5%(73.7%)と66.3%(65.8%)が各々特許ライセンス(技術事業化)分野と特許制度を挙げている([表 3.1])。特許ライセンス(技術事業化)関連の職務教育が必要と答えた比率は国公立大学及び私立大学類型で最も高い結果となっている。特に、国公立大学の89.9%が必要と答え、最も高い。また、政府出捐(研)の場合は特許情報検索が72.0%、その他公共(研)の場合は特許マップなど特許情報分析方法が72.6%で類型別では最も高い結果となっている。

[表 3.1]職務教育の実施を希望する場合、取り扱うべき内容

	全体	国公立 大学	私立 大学	政府 出捐(研)	その他 公共(研)
特許制度	66.3%	73.2%	67.9%	60.8%	53.2%
特許明細書の作成法	27.0%	49.9%	18.7%	28.0%	35.4%
特許情報の検索	55.6%	66.9%	50.2%	72.0%	54.9%
特許紛争(訴訟)	31.7%	46.7%	24.1%	44.8%	38.7%
特許情報の分析方法(特許マップ)	55.1%	76.9%	46.9%	44.8%	72.6%
特許ライセンス(技術事業化)	73.5%	89.9%	70.8%	66.4%	69.4%
海外特許出願及び訴訟	28.0%	56.6%	18.3%	60.8%	12.9%
営業秘密の保護	16.1%	33.3%	9.4%	33.6%	12.9%

注. 複数回答

知的財産人材の能力を高めるために政府が最も急ぐべき推進課題として全体の23.5%(23.8%)が既存人材向けの再教育プログラムの提供を挙げている([図 3.6])。また、知的財産関連のコンサルティング/相談の提供と企業を対象とする実務中心の教育課程の構成及び教材の開発を挙げた比率は各々22.7%と17.9%となっている。



[図 3.6]知的財産人材の能力を高めるために必要な政府政策

2011 年の 1 年間国内の大学及び公共(研)は知的財産担当者の人件費と知的財産関連の教育費として各々7,857 万ウォン(8,070 万ウォン)と 487 万ウォン(504 万ウォン)を支出している([表 3.2])。政府出捐(研)の場合は人件費対比教育費の比重(8.9%)が相対的に高い。⁶³

[表 3.2]知的財産担当者の人件費及び教育費の状況

	人件費 ⁶⁴	教育費 ⁶⁵	合計
全体	7,857 万ウォン	487 万ウォン	8,344 万ウォン
国公立大学	9,297 万ウォン	335 万ウォン	9,632 万ウォン
私立大学	4,624 万ウォン	254 万ウォン	4,878 万ウォン
政府出捐(研)	33,057 万ウォン	2,942 万ウォン	35,999 万ウォン
その他公共(研)	3,845 万ウォン	111 万ウォン	3,956 万ウォン

⁶³ 国公立大学の場合3.6%、私立大学の場合5.5%、その他公共(研)の場合2.9%を占めている。

⁶⁴ その他業務と兼職である場合、知的財産関連業務の比重を考慮して回答した結果である。

⁶⁵ 教育費は知的財産担当者対象の教育費と他従業員対象の教育費の合計である。

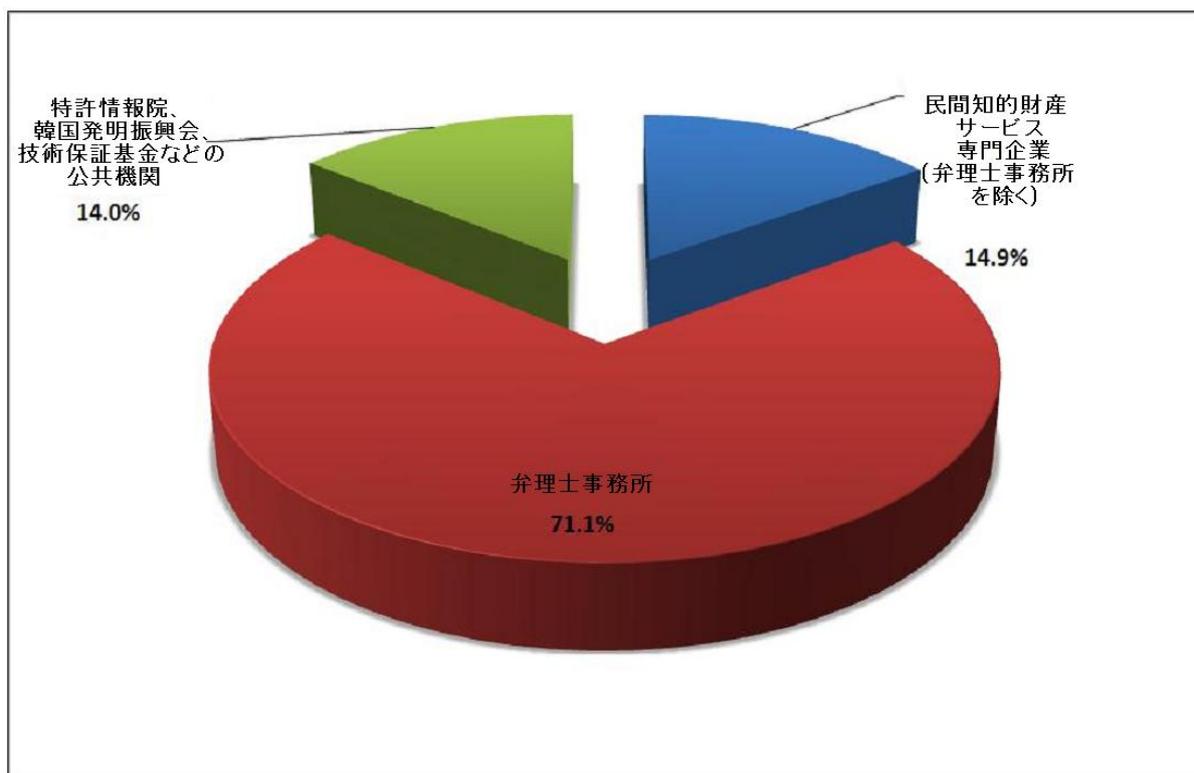
3.知的財産サービスの活用及び総合的な管理システムの構築状況

2011年に外部知的財産サービスを利用した大学及び公共(研)の比率は41.2%となっている([表 3.3])。特に、政府出捐(研)の場合も78.4%で他機関類型に比べて最も高い比率となっている。分野別平均支出額はIP翻訳サービスに1年平均4,216万ウォンを支出し、最も多い比重を占めているが、政府出捐(研)を除く機関の支出額は極めて小さい水準となっている。技術移転/取引分野の場合は平均3,839万ウォンを支出し、国公立大学と私立大学、その他公共(研)は各々平均5,262万ウォンと2,298万ウォン、6,011万ウォンを支出している。一方、IPコンサルティング/システムサービスに対する平均支出額は716万ウォンで最も低い結果となっている。

[表 3.3]知的財産サービスの利用状況

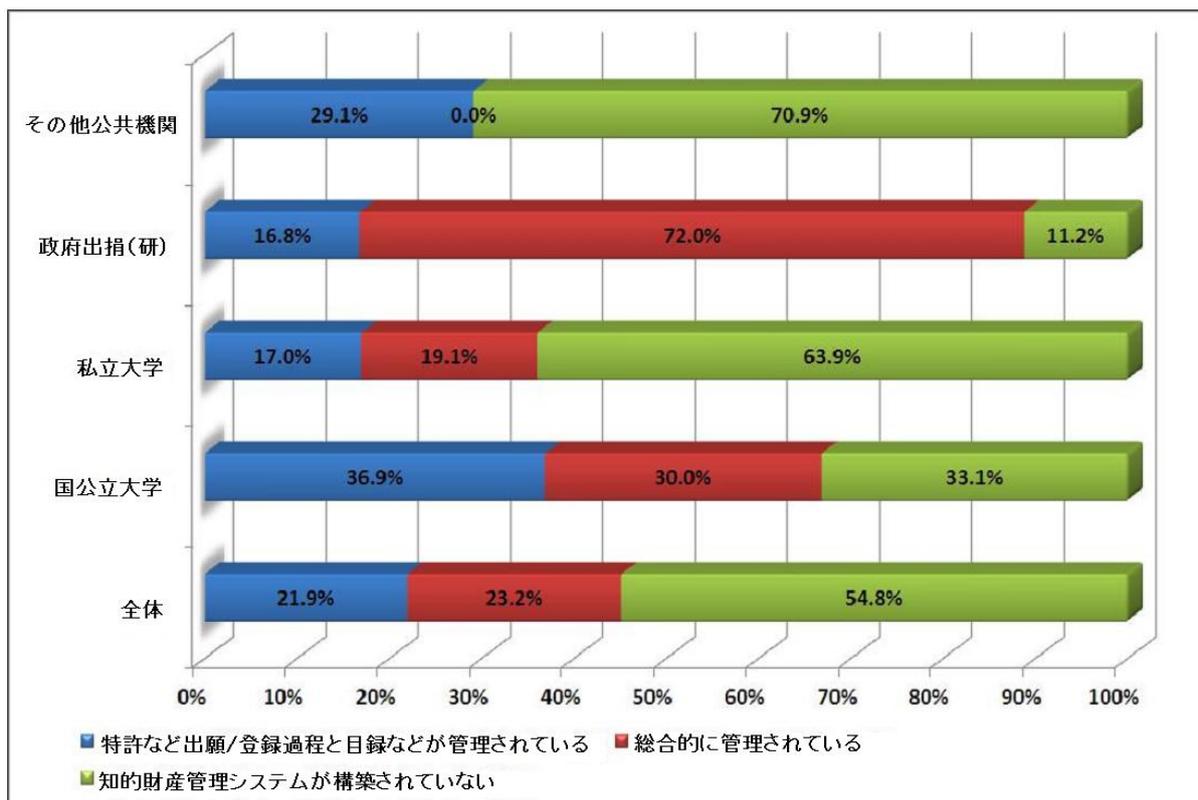
		全体	国公立 大学	私立 大学	政府 出捐(研)	その他 公共(研)
利用している		41.2%	60.2%	31.4%	78.4%	37.2%
2011 年の 支出 額	IP 情報調査/分析	1,255 万ウォン	704 万ウォン	924 万ウォン	3,293 万ウォン	929 万ウォン
	技術移転/取引	3,839 万ウォン	5,262 万ウォン	2,298 万ウォン	4,558 万ウォン	6,011 万ウォン
	IP 翻訳	4,216 万ウォン	325 万ウォン	360 万ウォン	24,415 万ウォン	-
	IP コンサルティング/システム	716 万ウォン	657 万ウォン	619 万ウォン	1,583 万ウォン	24 万ウォン
	合計	10,026 万ウォン	6,948 万ウォン	4,201 万ウォン	33,849 万ウォン	6,964 万ウォン

知的財産サービス提供機関別の利用比重は弁理士事務所が71.1%と最も多い比重を占めている([図 3.7])。その他に特許情報院、韓国発明振興院など公共機関は14.0%、弁理士事務所を除いた民間知的財産サービス専門企業の利用比重は14.9%に止まっている。



[図 3.7]知的財産サービス提供機関別の利用比重

知的財産サービス提供機関別の利用比重は機関類型別で見ると、全ての機関類型において弁理士事務所を利用する場合は最も大きな比重を占めている。その他に国公立大学と私立大学の場合は公共機関を各々14.9%、12.0%利用しており、政府出捐(研)とその他公共研究機関の場合は民間知的財産サービス専門企業を23.3%、22.9%利用している。



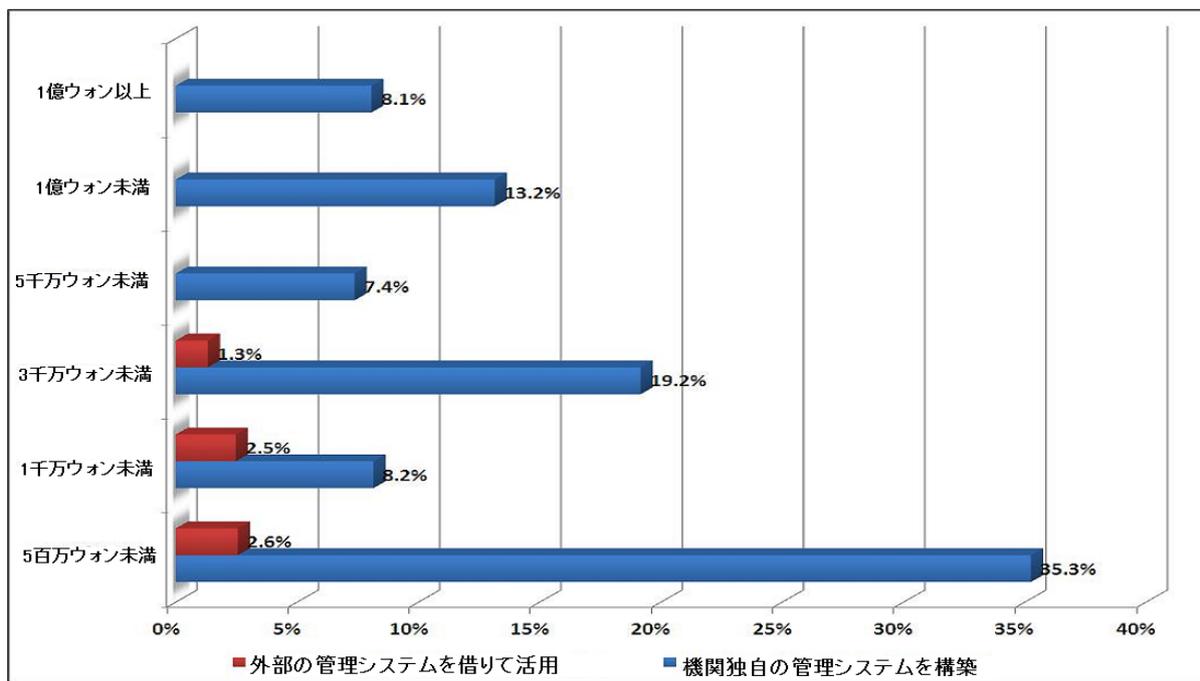
[図 3.8]知的財産管理システムの構築及び活用状況

現在総合的な知的財産管理システムを構築・活用している大学、公共(研)の比率は45.2%(46.5%)となっている([図 3.8])。これを細分化してみると、発明届出から出願、中間事件、登録、維持、放棄などに係わる行政的手続きと特許費用、関連情報などを管理するシステムを構築している比率が21.9%となっており、特許などの出願・登録過程と目録などを業績評価などの人事管理、研究課題管理システム、技術移転システムと連動させて総合的に管理している比率は23.2%となっている。機関類型別では政府出捐(研)が88.8%と最も高く、その他公共(研)が29.1%と最も低い。

知的財産管理システムを構築・活用している場合、構築方法を調べてみると、殆どの大学、公共(研)が機関独自の管理システムを構築・活用(91.2%)しており、外部の管理システムを借りて活用している大学・公共研究機関の比率は8.8%となっている。

知的財産管理システムの構築・活用にかかる費用は機関独自の管理システムを構築して活用する場合500万ウォン未満が35.3%と最も多く、1億ウォン以上使う大学・

公共研究機関も 8.1%となっている([図 3.9])。外部管理システムを借りて活用する場合も 500 万ウォン以下が 2.6%と最も多い。

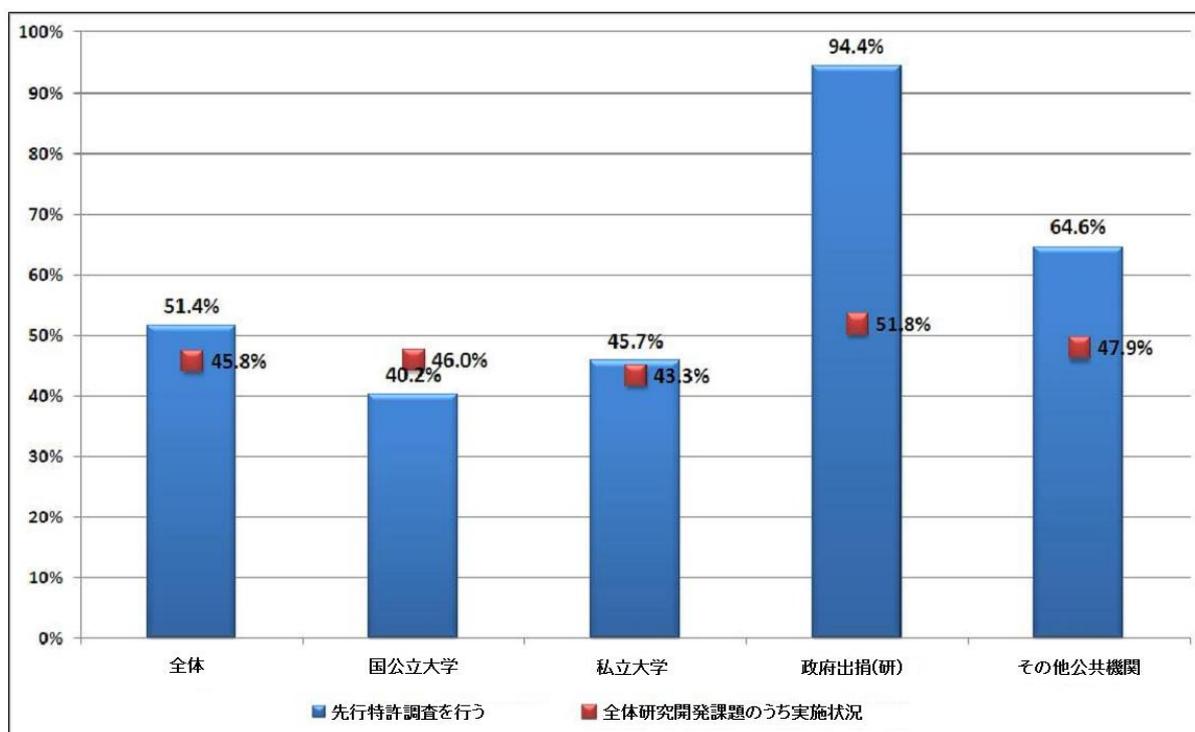


[図 3.9]知的財産管理システムの構築費用

第2節 知的財産の創出

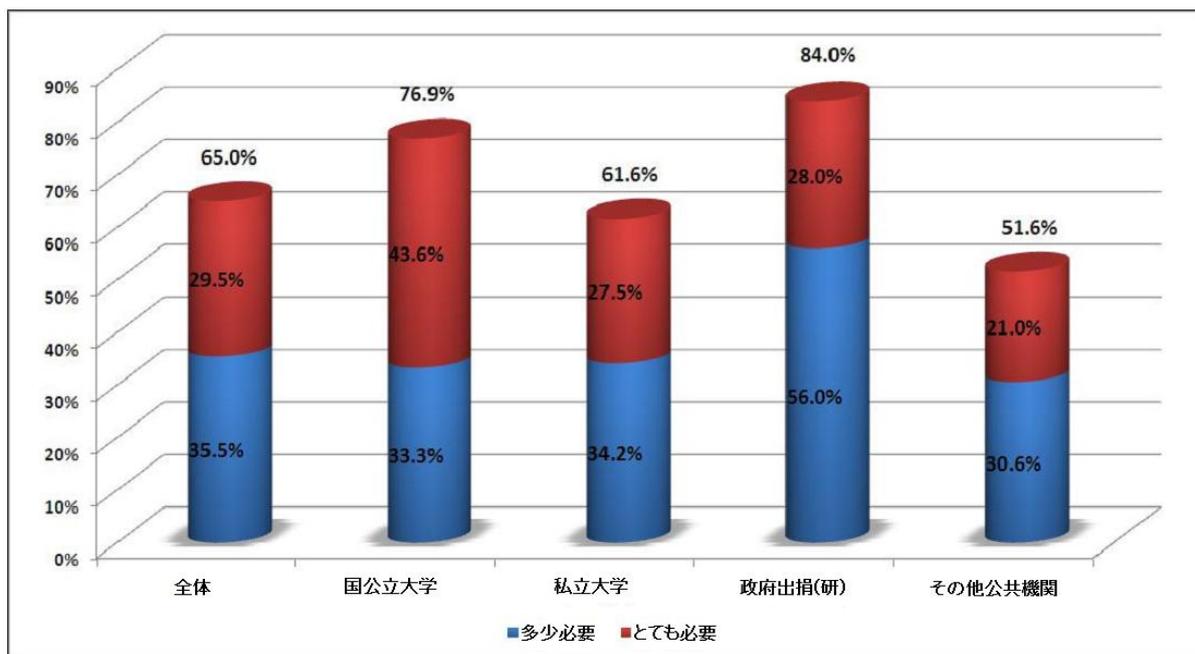
1.研究開発過程における特許情報の活用

研究開発企画段階において先行特許情報を調査・活用している大学及び公共(研)の比率は全体の 51.4%(52.3%)となっている([図 3.10])。機関類型別では政府出捐(研)が 94.4%と最も高く、その他公共機関、私立大学、国公立大学が続いている。また、全体研究開発課題のうち調査・活用の実行比率は全体の場合 45.8%(44.9%)となっており、政府出捐(研)の場合が最も高い 51.8%となっている。



[図 3.10]先行特許情報調査の現状

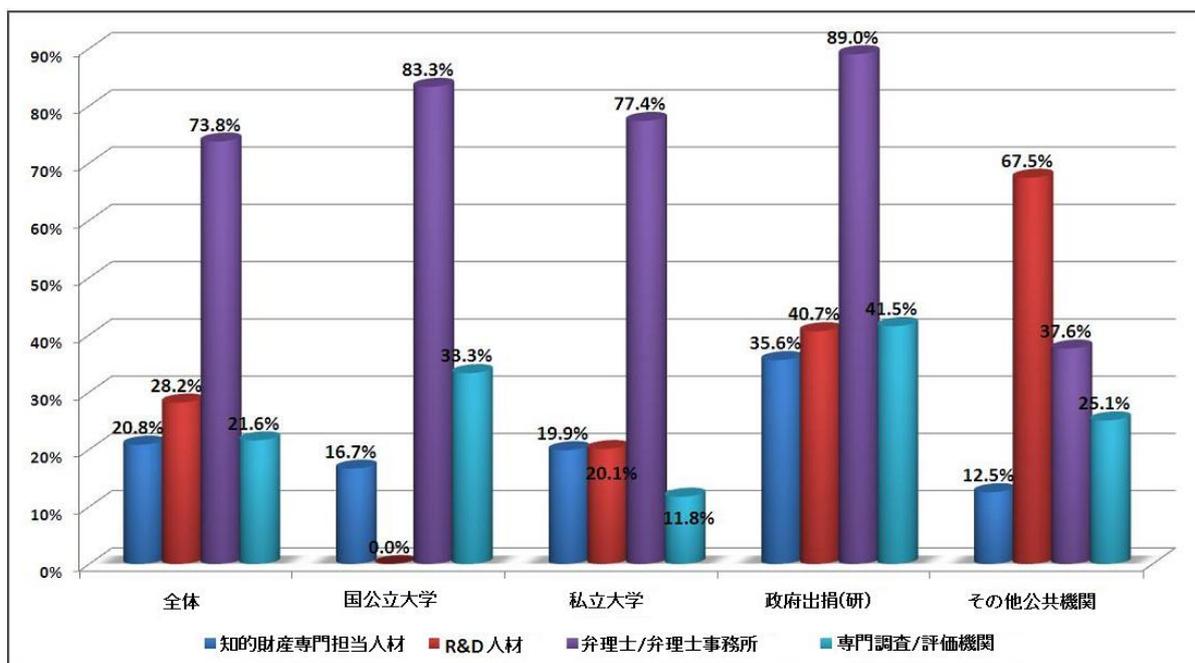
大学及び公共(研)の知的財産担当者が認識している特許(技術)情報調査の必要性と関連して全体の 65.0%(65.5%)が必要またはとても必要と答えている([図 3.11])。機関類型別では政府出捐(研)と国公立大学の各々 84.0%と 76.9%が先行技術調査の必要性に対して肯定的に回答し、相対的に高いことがわかる。



[図 3.11] 先行特許情報調査の必要性

先行特許調査を行っている場合の 73.8%(74.1%)が弁理士に該当業務を依頼している([図 3.12])。また、研究開発人材が直接行っていると答えた機関は 28.2%(27.4%)となっている。知的財産専門担当人材、専門調査/評価機関が行っていると答えた機関は各々20.8%(20.7%)と 21.6%(19.6%)となっている。

機関類型別でみると、政府出捐(研)の場合は弁理士/弁理士事務所に該当業務を依頼する比率が 89.0%(89.0%)で最も高く、国公立大学が 83.3%(同一)、私立大学が 77.4%(77.7%)と続いている。その他公共研究機関の場合、研究開発人材が先行特許調査を行っている と答えた比率が 67.5%(64.8%)と非常に高い。

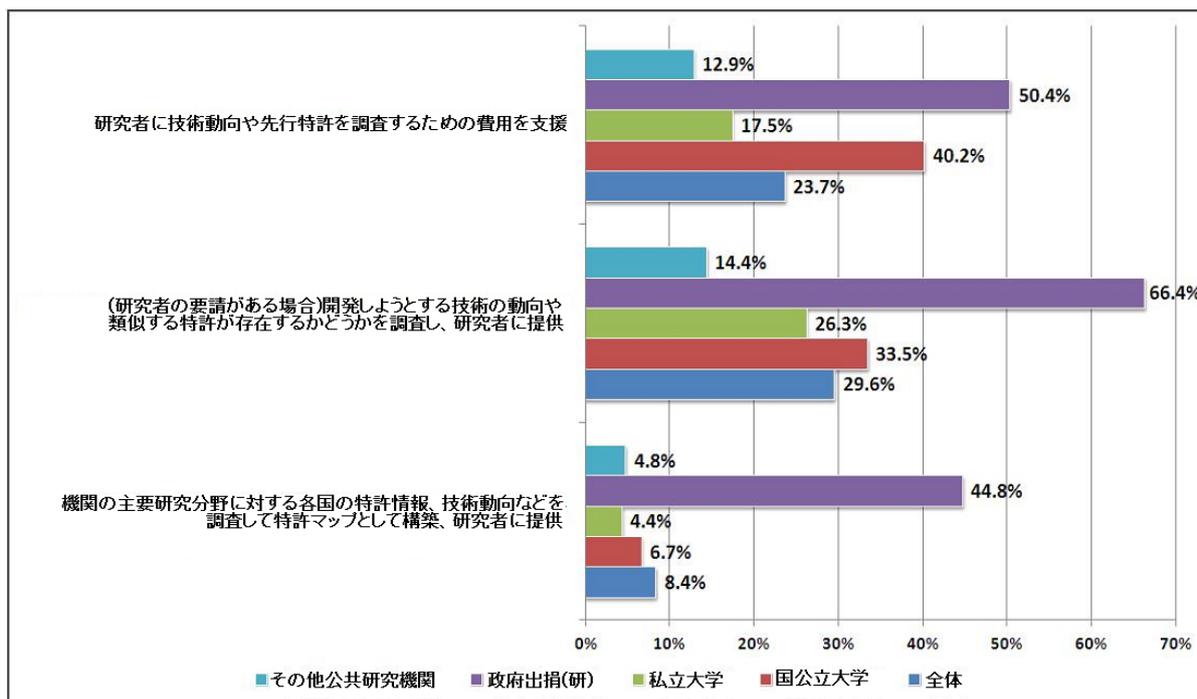


[図 3.12] 先行特許調査を行う場合の実施人材

注. 複数回答

先行特許調査のために機関レベルで支援を行っている比率は全体の 44.5%となっている([図 3.13])。支援の種類別でみると、全体機関の 29.6%が研究者の要請がある場合は開発しようとする技術の動向や類似する特許が存在するかどうかを調査して研究者に提供している。特に、政府出捐(研)の 66.4%が該当支援を提供している。また、全体機関の 23.7%が研究者に技術動向や先行特許を調査するための費用支援を行っている。特に、政府出捐(研)の 50.4%、国公立大学の 40.2%が技術動向及び先行特許を調査するための費用支援を行っている。

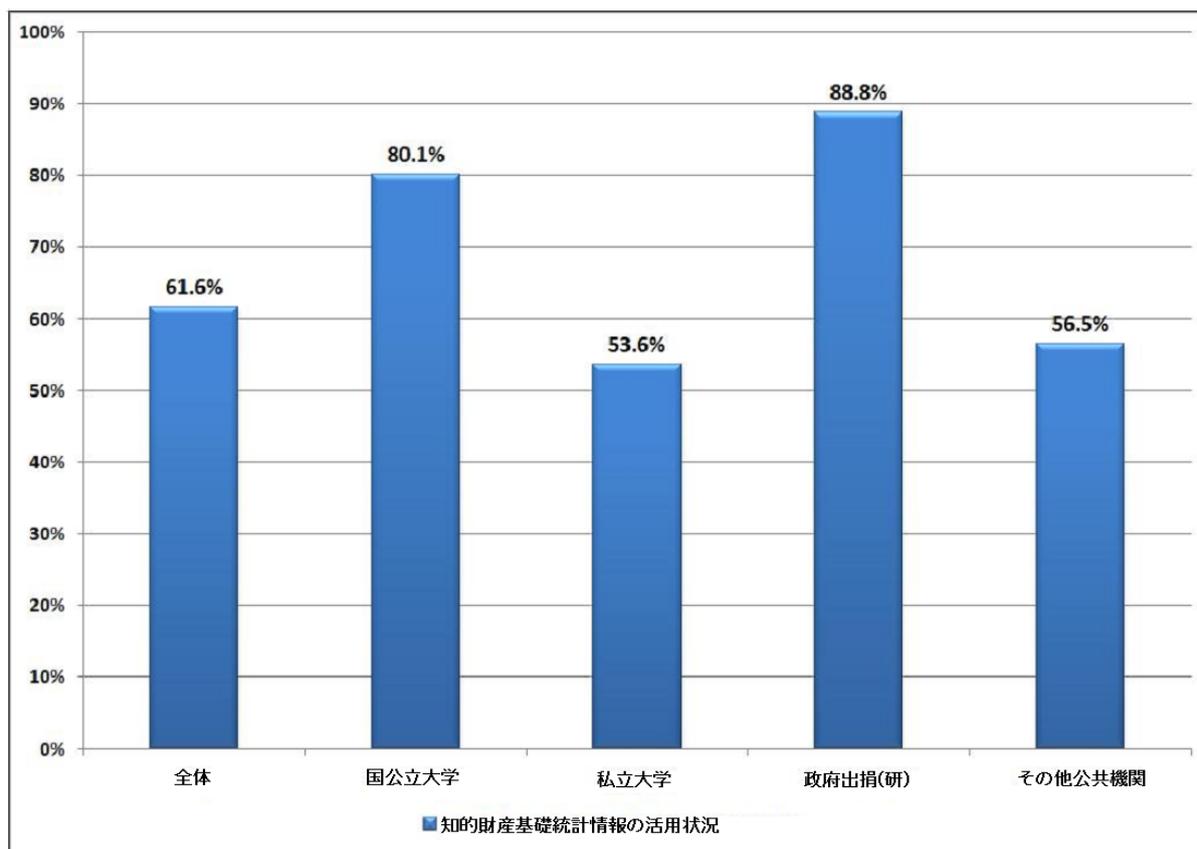
また、機関の主要研究分野に対する各国の特許情報、技術動向などを調査して特許マップとして構築、研究者に提供する比率も 8.4%となっており、機関類型別でみると、政府出捐(研)の場合 44.8%と他機関類型に比べて高い比率を占めている。



[図 3.13]先行特許調査に対する機関の支援

大学及び公共(研)の場合、知的財産統計など基礎統計情報を活用している比率は全体の 61.6%(63.5%)となっている。機関類型別でみると、政府出捐(研)の活用比率が 88.8%と最も高く、その後を国公立大学、その他公共機関、私立大学と続いている([図 3.14])。

主に活用する統計指標として「特許登録内容などの検索」が回答者の 58.2%となっており、「年度別出願件数」、「登録件数」が各々 22.6%、21.9%となっている。「特許登録内容などの検索」の場合は国公立大学が 66.5%と最も多く活用しており、私立大学が 59.5%、政府出捐(研)が 49.5%、その他公共研究機関が 45.7%と全ての機関類型において最も多く活用している。頻繁に公表して欲しい統計指標としては、「産業部門別出願件数」を求める比率が 6.3%と最も多く、「登録件数」及び「年度別出願件数」に対する比率が各々 6.0%、4.5%を占めている。

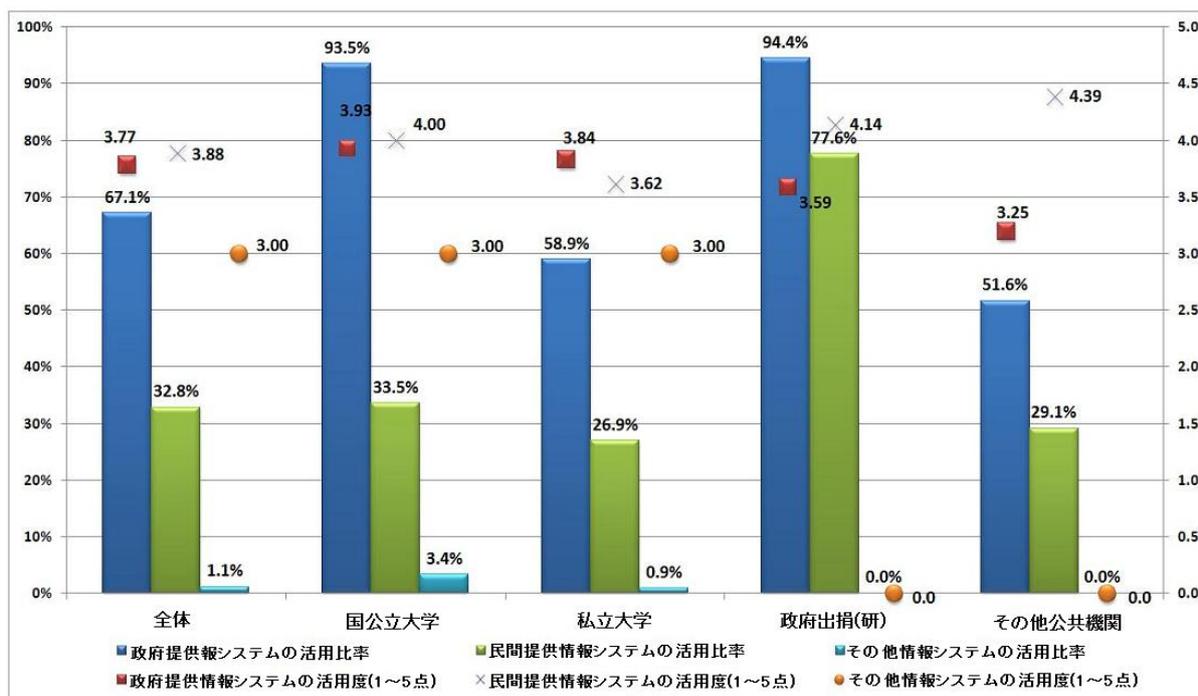


[図 3.14]知的財産基礎統計情報の活用状況

政府または民間が提供する知的財産情報システムの活用度を見ると、まず政府が提供する KIPRIS などの知的財産情報システムを活用していると答えた比率は 67.1% (69.1%)となっている([図 3.15])。活用している機関のうち活用度が高いと答えた比率は 40.0%(41.1%)となっており、平均活用度(5点尺度)は 3.77点(3.76点)となっている。機関類型別では政府出捐(研)の 94.4%(同一)、国公立大学の 93.5%(95.0%)が政府が提供する情報システムを活用していると答え、私立大学、その他公共研究機関より高い。活用度が高いと答えた比率は国公立大学が 66.9%(67.6%)、政府出捐(研)が 44.8%(同一)と高く、平均活用度は国公立大学が 3.93点(3.89点)、私立大学が 3.84点(同一)の順となっている。

民間が提供する知的財産情報システムを活用していると答えた比率は 32.8% (33.8%)となっており、活用している機関のうち活用度が高いと答えた比率は 22.3% (22.7%)となっている。機関類型別では、政府出捐(研)が 77.6%(同一)と最も高く、国公立大学が 33.5%(34.8%)と続いている。活用度が高いと答えた比率もまた政府出捐

(研)が 60.8%(同一)が最も高く、その他公共研究機関が 24.3%(21.7%)、国公立大学が 23.5%(24.3%)となっている。平均活用度はその他公共機関が 4.39 点(4.25 点)と最も高く、政府出捐(研)が 4.14 点(同一)、国公立大学が 4.00 点(同一)の順となっている。その他情報システムの場合、全体の 1.1%(1.2%)が活用していると答え、国公立大学が 3.4%(3.5%)、私立大学が 0.9%(同一)となっている。



[図 3.15]機関類型別知的財産情報システムの活用

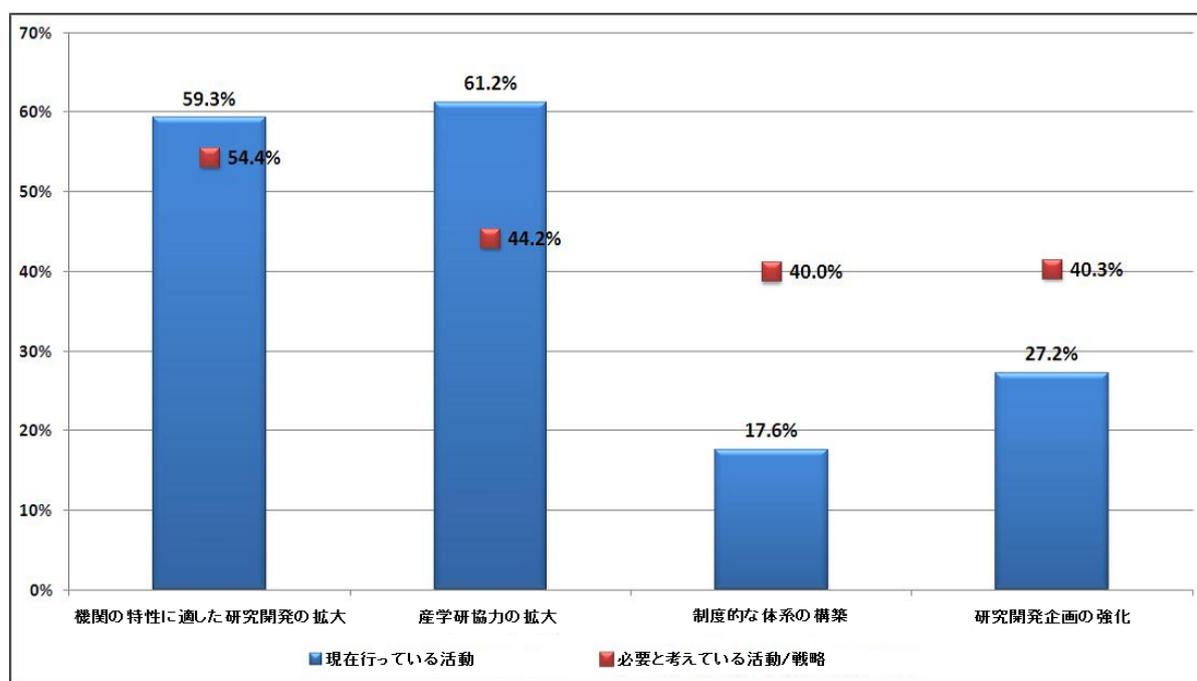
政府が提供する情報システムの中では KIPRIS が 93.4%と最も高く、民間が提供する情報システムの中では WIPS が 92.5%と最も高い。その他の場合、「世界国家別特許庁」、「NDSL」を活用しているという回答が各々51.7%、48.3%を占めている。

2.知的財産を創出するための活動戦略

優れた知的財産を創出するための戦略として、大学及び公共(研)の 61.2%(62.3%)が産学研協力を通じた共同・委託研究開発を拡大していると答えている([図 3.16])。また、機関特性に適した研究開発課題を発掘し、機関独自の研究開発投資を拡大していると答えた比率も 59.3%(59.5%)とその後を続いている。一方、優れた知的財産を創

出すための方法として研究開発企画の際に市場ニーズが反映できる制度的な体系を構築していると答えた比率は 17.6%(18.4%)と最も低い。

機関類型別では、優秀な知的財産を創出するため、私立大学及び国公立大学の場合産学研協力を通じた共同・委託研究開発の拡大に力を入れているという答えが各々 72.7%、56.8%と最も多いが、その他公共(研)と政府出捐(研)の場合は機関の特性に適した研究開発課題を発掘し、機関独自の研究開発投資を拡大しているという回答が各々 95.2%、88.8%と最も大きな比重を占めている。また、研究開発を企画する時に市場ニーズが反映できる制度的な体系を構築している比率は政府出捐(研)が 44.8%と他機関類型に比べて高い。



[図 3.16]優れた知的財産を創出するための活動及び戦略

注. 複数回答

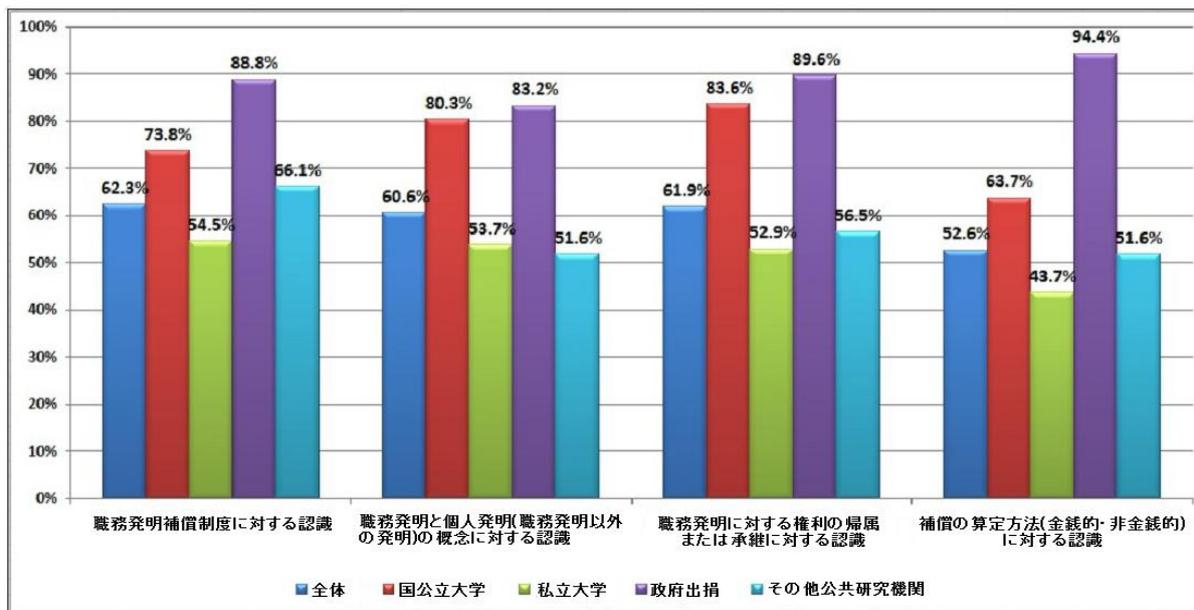
一方、現在の行っているかどうかは関係なく、優秀な知的財産を創出するために必要であると思われる活動や戦略は機関の特性に適した課題の発掘及び機関独自の研究開発の拡大と答えた比率が 54.4%(55.1%)と最も高い。研究開発企画の際に市場ニーズが反映できる制度的な体系を構築することが必要であると答えた比率は全体の 40.0%(41.0%)と最も低いですが、政府出捐(研)の 66.4%が必要と答えており、最も高い比

率を占めている。にもかかわらず産学研協力を通じた共同/委託研究開発の拡大、研究開発企画の際に市場ニーズが反映できる制度的な体系の構築、中大型重要研究開発課題における研究開発企画強化に向けた活動及び戦略の必要性に対しては全体的に同じ水準の必要性を提示している。

特に、研究開発企画の際に市場ニーズが反映できる制度的な体系を構築する戦略と重要研究開発課題における優秀特許の創出に向けた研究開発企画強化戦略の場合は現在大学及び公共(研)が行っている比率より重要であると認識している機関の比率がより高いことを踏まえると、今後強化あるいは支援が求められる部分である。

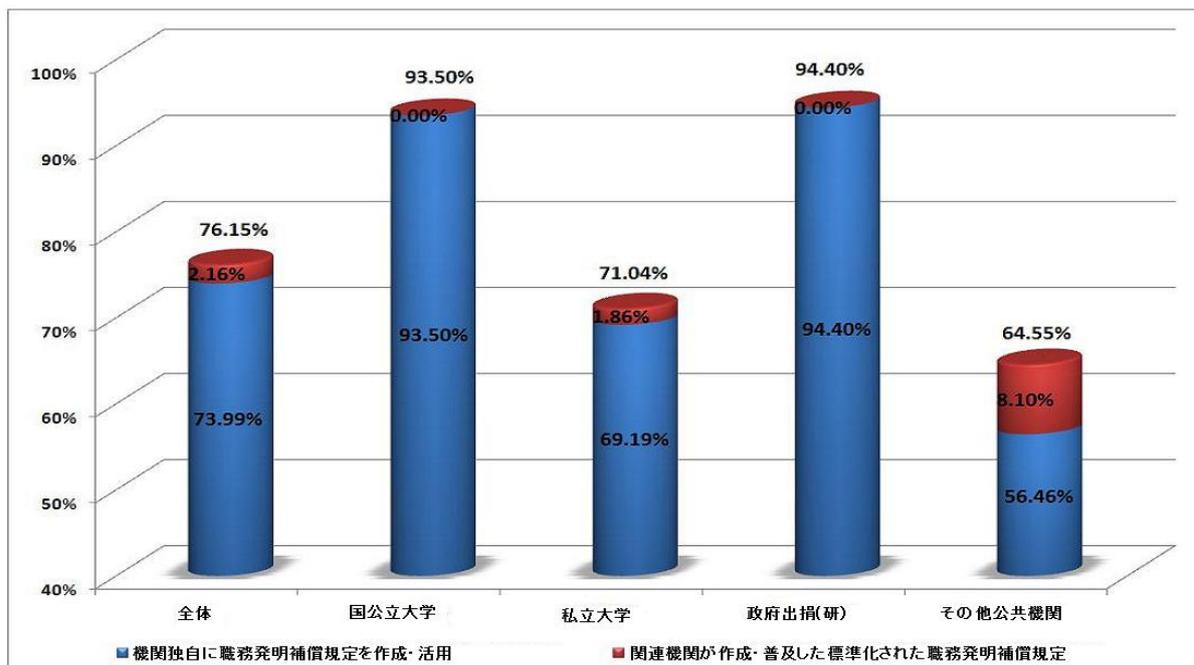
3.職務発明補償

職務発明補償制度に関して全体の 62.3%(64.7%)がよく知っているまたは十分よく知っていると答えている。機関類型別では、政府出捐(研)の 88.8%がよく知っているまたは十分よく知っていると答えて認識度が最も高く、国公立大学、その他公共研究機関が各々73.8%、66.1%と続いている。職務発明と職務発明以外の発明である個人発明の概念、職務発明に対する権利の帰属または承継、補償の算定方法と関連して全ての政府出捐(研)の場合、認識度が最も高い比率を占めている。私立大学及びその他公共研究機関の場合は相対的に認識度が低く、したがって上記の機関を対象とする職務発明補償に対する認識度を高めることで制度を拡大する方法を講じる必要があると判断される。



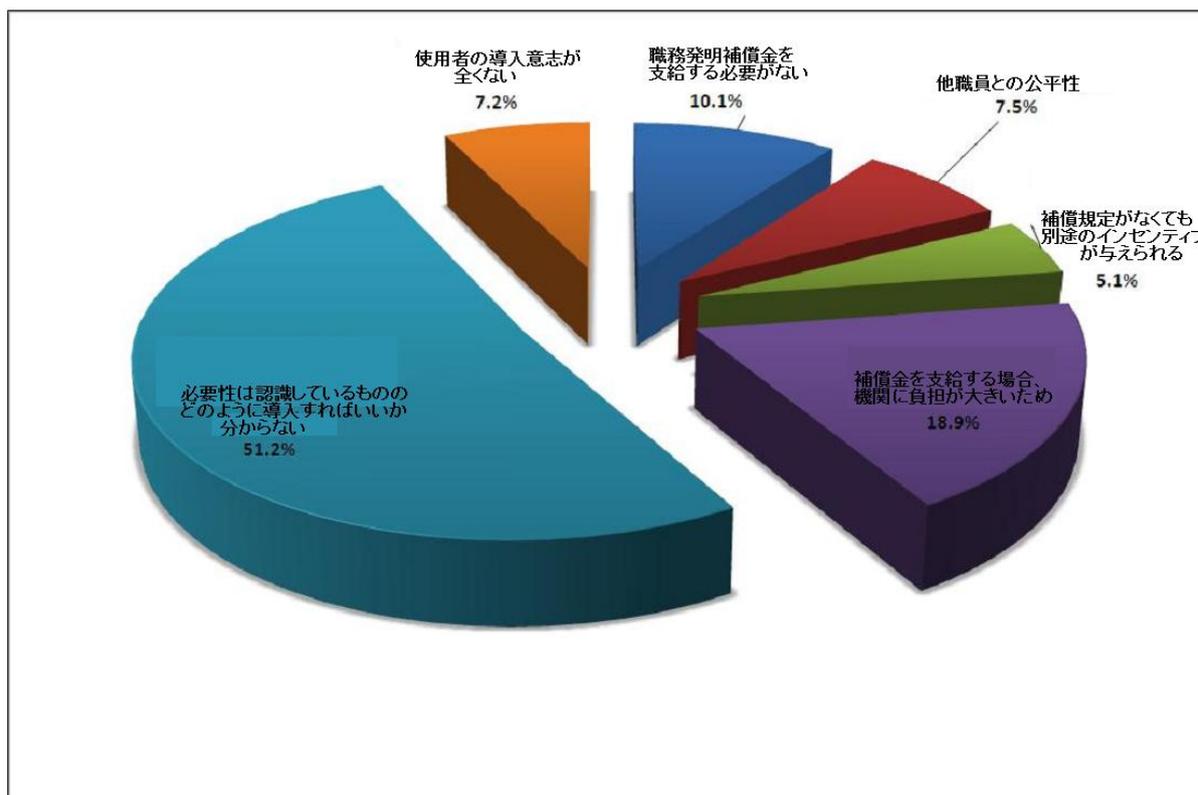
[図 3.17]職務発明補償制度に対する認識度

職務発明補償規定を保有し、これを活用している大学、公共(研)の比率は 76.2% (78.1%)となっている([図 3.18])。これを細分化すると、機関独自に職務発明補償規定を作成して活用している比率が 74.0%(76.0%)となっており、特許庁など関連機関が作成・普及して標準化された職務発明補償規定を保有・活用している比率は 2.2%(2.0%)となっている。



[図 3.18]職務発明意補償規定の保有及び活用状況

機関類型別では、政府出捐(研)、国公立大学、私立大学の中で職務発明補償規定を保有・活用している比率は各々94.4%、93.5%、71.0%となっており、その他公共機関は64.6%と相対的に低い。



[図 3.19]職務発明補償規定を保有していない場合、その主な理由

補償規定を保有していない理由として、必要性は認識しているもののどのように導入すればいいかわからないと答えた比率と補償金を支給する場合機関に負担が大きいためと答えた比率が51.2%と18.9%を占めている([図 3.19])。職務発明補償金を支給する必要がないためと答えた比率も10.1%を占めており、他職員との公平性問題及び使用者の導入意志が全くない場合も各々7.5%、7.2%となっている。

職務発明補償の類型別実施状況を見ると次の[表 3.4]のとおりである。国内特許登録補償、海外特許登録補償、他社実施補償を実施している比率が各々90.6%(90.0%)、85.4%(84.5%)、82.6%(82.3%)と高い。

但し、機関類型別では国公立大学及び政府出捐(研)の場合には他社実施補償比率が各々92.8%、100%と最も高い。国公立大学の場合は国内特許登録補償が85.7%と続いており、政府出捐(研)の場合には国内特許登録補償及び海外特許登録補償、処分補償が全部94.1%となっている。

[表 3.4]職務発明補償の類型別実施比率

	全体	国公立 大学	私立 大学	政府 出捐(研)	その他 公共(研)
発明提案(発明届出)補償	8.2%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%
出願留保補償	6.6%	0.0%	9.2%	0.0%	12.5%
国内特許出願補償	46.0%	32.3%	49.0%	53.4%	50.2%
国内特許登録補償	90.6%	85.7%	90.0%	94.1%	100.0%
海外特許出願補償	45.4%	35.9%	48.8%	53.4%	37.6%
海外特許登録補償	85.4%	82.1%	87.3%	94.1%	72.5%
その他産業財産権国内登録補償	59.7%	39.2%	65.3%	59.3%	70.2%
その他産業財産権海外登録補償	54.5%	24.9%	64.0%	59.3%	57.6%
自社実施補償	51.5%	39.0%	63.3%	17.8%	47.5%
他社実施補償	82.6%	92.8%	77.7%	100.0%	70.2%
処分補償	78.6%	82.3%	74.0%	94.1%	80.0%

職務発明補償と関連する制度の効果と関連し、職務発明に対する補償実施または補償レベルの拡大が機関内発明件数及び品質向上と技術流出防止に効果的であると答えた比率が各々59.3%と36.0%となっている。

また、職務発明補償金に対する所得税非課税制度が発明件数及び品質向上と技術流出防止に効果的であると答えた比率は各々60.7%、46.2%を占めている。

4.効果的な知的財産創出のために必要な政策支援

大学及び公共(研)の効果的な知的財産創出のために特許情報活用拡散事業の拡大など先行特許調査と特許情報の活用支援が必要と答えた比率は全体の 71.8%と最も高い([表 3.5])。特に、政府出捐(研)の 89.6%が必要と答えており、様々な政策支援の中で最も高い比重で必要と答えている。国公立大学の場合は専門家派遣、知財権コンサルティング事業の拡大など大学と公共研究機関の知的財産権創出活動支援が必要と答えた比率が 90.1%と最も高く、同時に研究者などを対象とする知的財産権関連教育支援も同じく 90.1%の比率で最も必要であると答えている。その他公共(研)の場合は 74.2%が多様な技術分野に対する特許マップの構築支援が最も必要な政策支援と答えている。

[表 3.5]効果的な知的財産創出のための政策支援の必要性

	全体	国公立 大学	私立 大学	政府 出捐(研)	その他 公共(研)
職務発明補償制度を導入したり、補償水準が 拡大できるように支援	64.9%	70.0%	66.2%	56.0%	58.0%
特許情報活用拡散事業の拡大など先行特許調 査と特許情報活用支援	71.8%	86.8%	68.8%	89.6%	53.2%
専門家派遣、知財権コンサルティング事業の 拡大など大学と公共研究機関の知的財産権創 出活動支援	68.4%	90.1%	61.4%	84.0%	61.3%
多様な技術分野に対する特許マップ構築支援	69.1%	76.9%	65.3%	72.8%	74.2%
研究者などを対象とする知的財産権関連教育 支援	70.8%	90.1%	65.2%	78.4%	66.1%

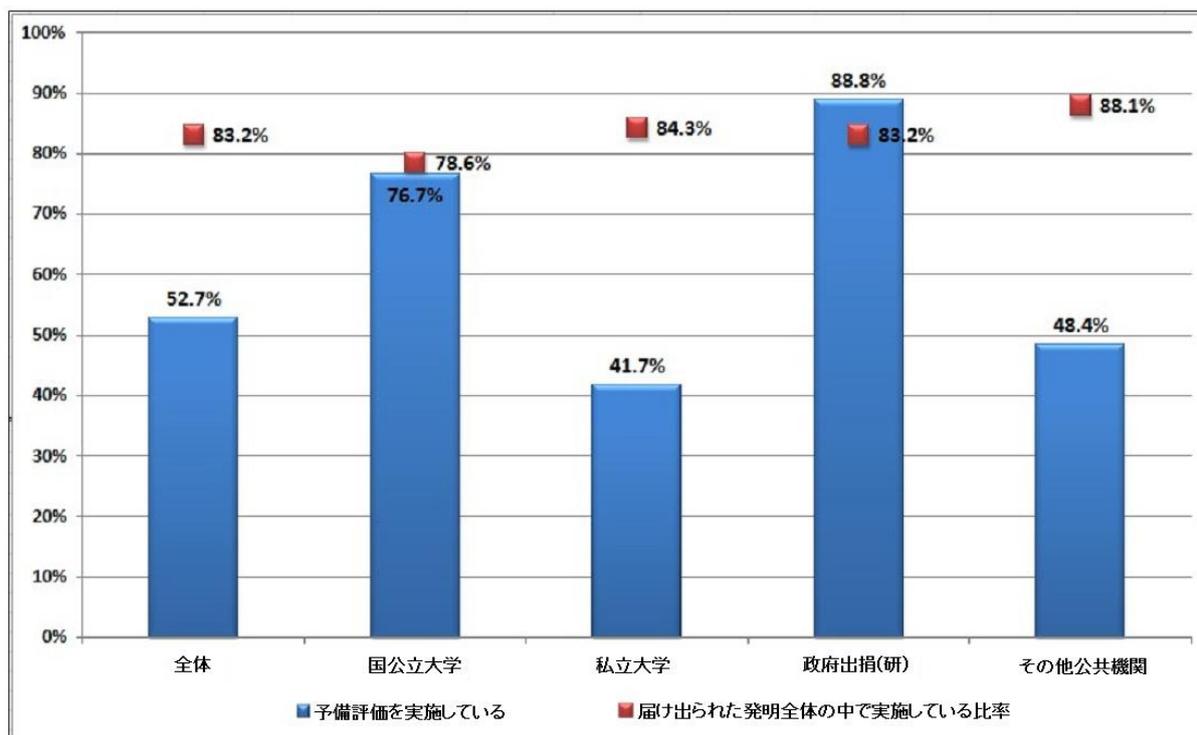
注. (%)は 5 点尺度(1：必要性が最も低い、5：必要性が最も高い)で[(4 点と 5 点と答えた企業数)/(総回答機関数)]×100(%)

第3節 知的財産の保護

1. 予備評価実施状況及び方法

産業財産権の出願などに先立ち機関内で予備評価を行っている大学及び公共(研)の比率は 52.7%(54.2%)となっている([図 3.20])。機関類型別で見ると、予備評価実施比率が最も高い機関は政府出捐(研)で 88.8%(同一)に達している。一方、予備評価を実施している比率が最も低い機関は私立大学で 41.7%(42.3%)に止まっている。

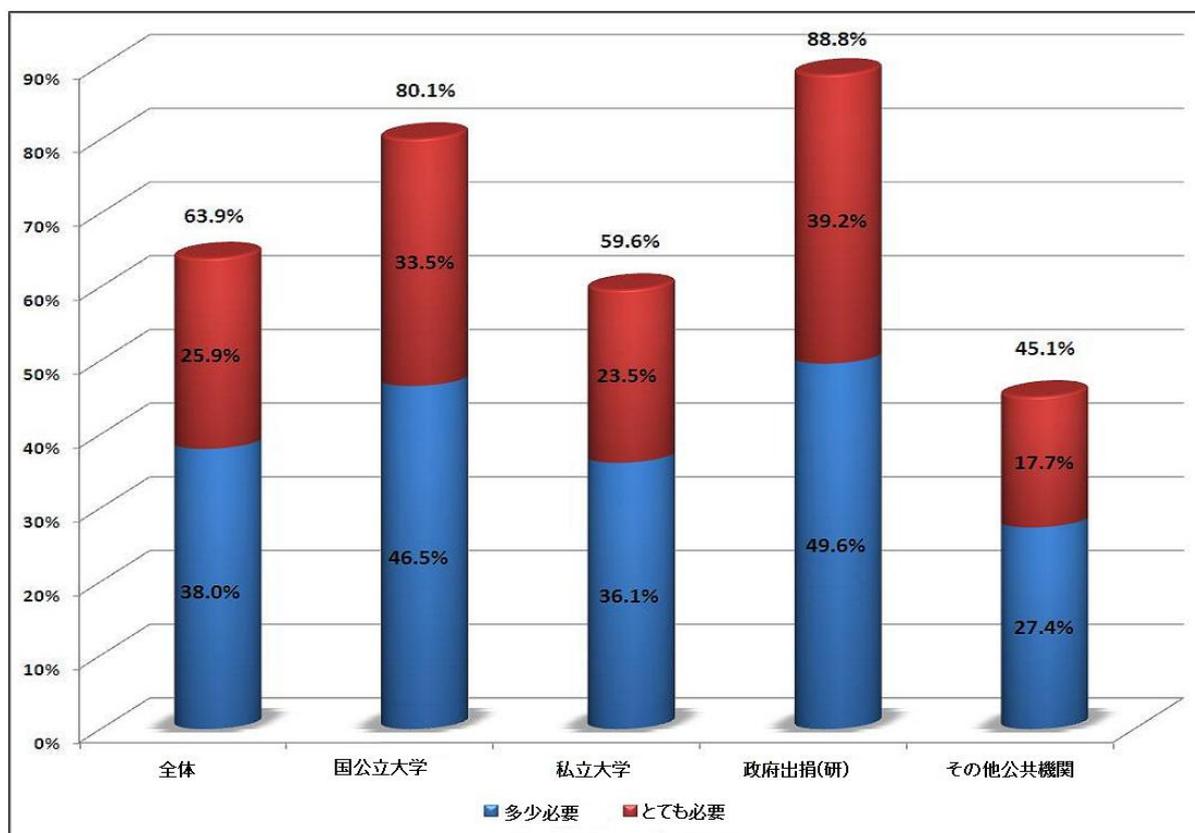
また、予備評価を実施する場合、届け出られた発明件数全体の中で平均 83.2% (83.1%)に対して実施している。届け出られた発明件数全体の中の予備評価実施比率はその他公共研究機関の場合が 88.1%と最も高く、私立大学が 84.3%、政府出捐(研)が 83.2%と続いている。



[図 3.20]産業財産権の出願などに先立ち予備評価の実施状況

産業財産権を出願する前に予備評価を実施する必要性に対しては[図 3.21]のように全体の 63.9%(64.8%)が必要またはとても必要と答えている。これは現在の実施比率である 52.7%に比べて高い数値であり、予備評価の必要性に対して認識はしているもののあらゆる事情によって実施出来ない機関が相当数存在することを意味する。

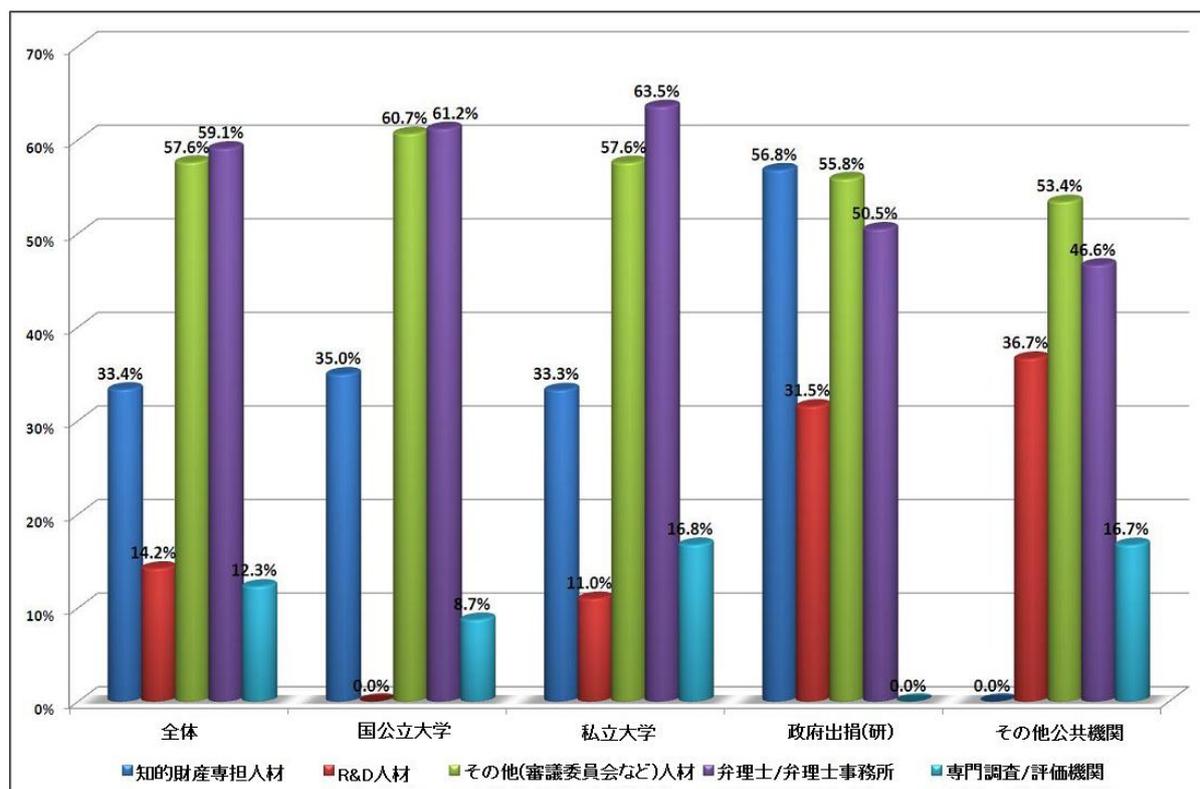
機関類型別では、予備評価が必要と答えた比率は政府出捐(研)の 88.8%(同一)が最も高い。特に、とても必要と答えた比率が 39.2%に達している。また、国公立大学の 80.1%(81.1%)が予備評価が必要と答え、とても必要と答えた比率は 33.5%となっている。



[図 3.21]予備評価実施の必要性

一方、予備評価を実施していると答えた場合の 59.1%(59.3%)が弁理士に該当業務を依頼すると答えている([図 3.22])。その他(企画など)人材、知的財産専門担当人材、R&D 人材が該当業務を行っているとした比率も各々 57.6%(56.5%)、33.4%(33.6%)、14.2%(14.9%)となっている。専門調査/評価機関に依頼する場合は全体の 12.3%

(12.1%)に過ぎない。機関類型別では、知的財産専門担当人材が予備評価を実施している比率は政府出捐(研)が 56.8%と相対的に高く、国公立大学の場合は弁理士に該当業務を依頼したり、企画などのその他人材が行っている場合が各々61.2%、60.7%と相対的に高い。

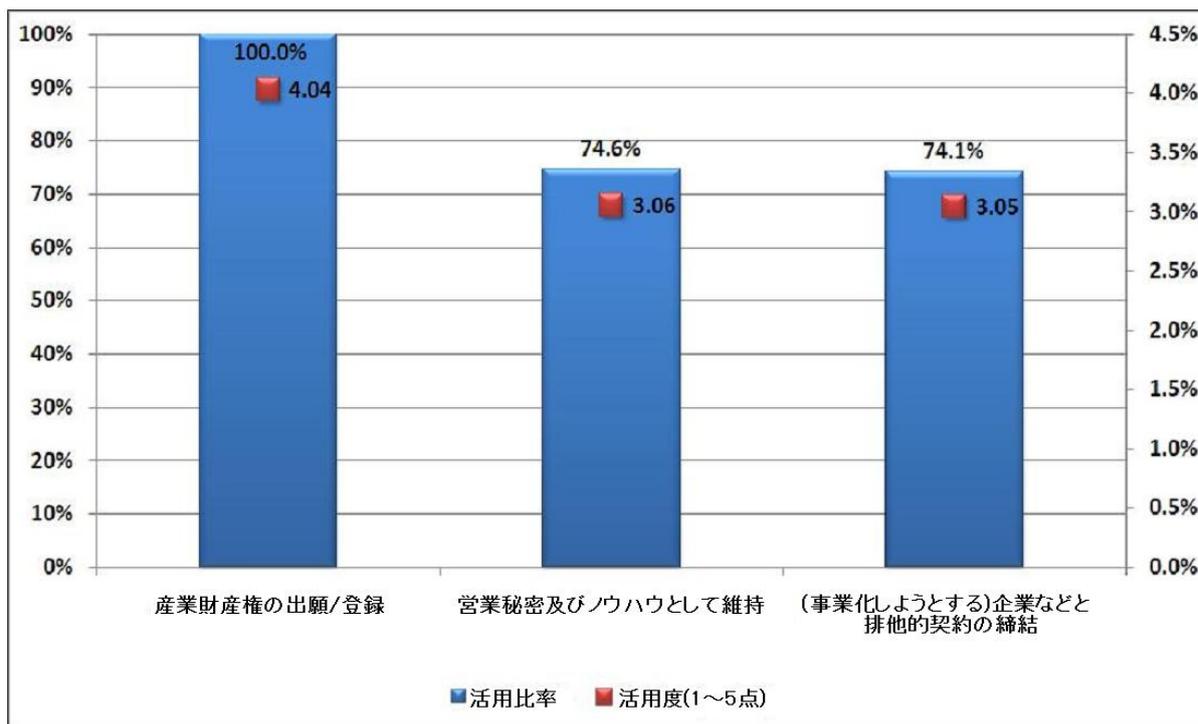


[図 3.22]予備評価を実施している場合の実施人材

注. 複数回答

2.研究開発成果の保護戦略

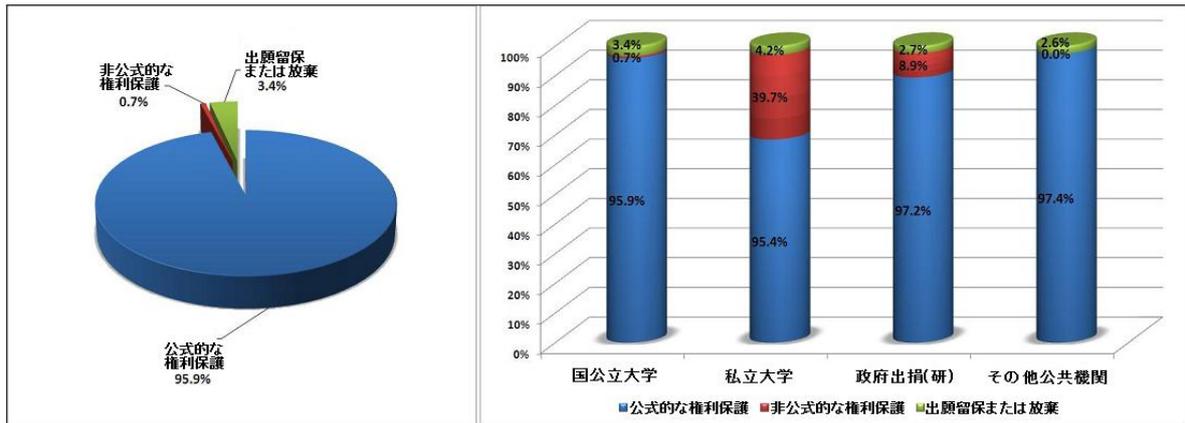
研究開発活動の成果を保護するために活用する戦略として特許など産業財産権の出願を活用すると答えた比率は全体の 100%(同一)を占めている([図 3.23])。また、機関内の営業秘密及びノウハウとして維持する戦略と事業化を図る企業などと排他的な契約を締結すると答えた比率も各々74.6%(76.3%)と 74.1%(74.7%)に達している。



[図 3.23]研究開発成果保護戦略の活用比率及び活用度

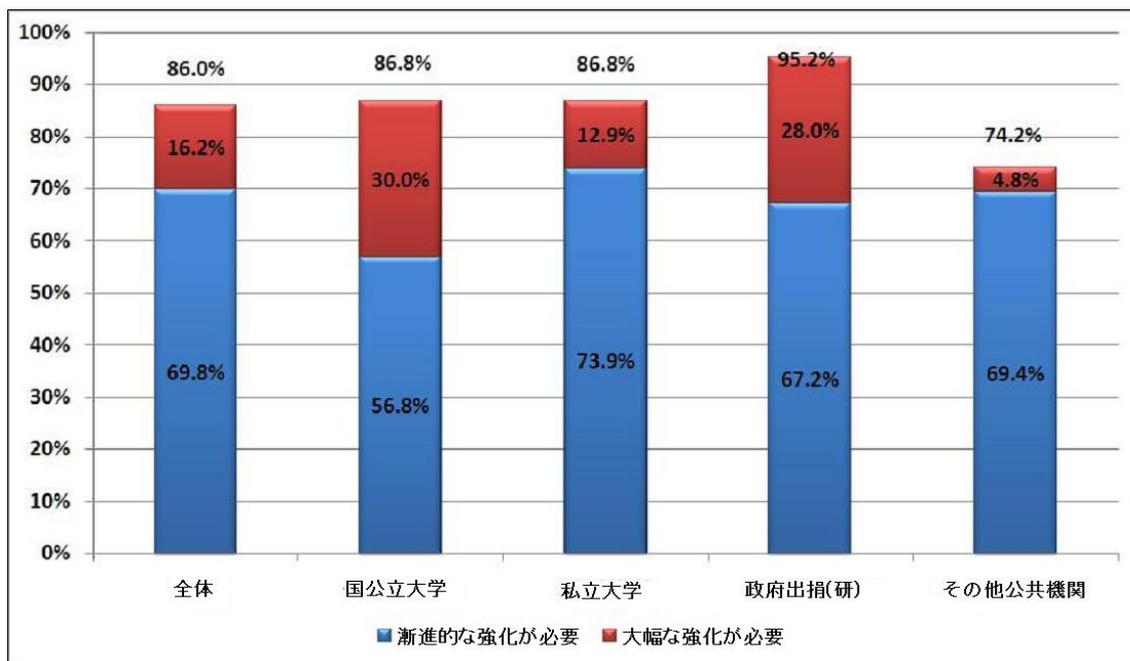
2011年の1年間発明届出件数は平均104.1件(107.6件)となっている。機関類型別では、政府出捐(研)が平均330.5件(同一)と最も多く、国公立大学、私立大学、その他公共(研)が各々167.7件(173.6件)、70.3件(73.6件)、23.1件(20.4件)となっている。

このうち産業財産権の出願など公式的な権利保護手続きを踏んだ比率は[図 3.24]のように、機関平均95.9%(96.2%)となっている。また、全体の3.4%(2.9%)が経済性、技術性の不足などの理由で出願を留保または放棄しており、非公式的な権利保護比率は0.7%(0.9%)となっている。全ての機関類型において公式的な権利保護比率は高く、出願留保または放棄の比率も同水準を維持している。しかし、私立大学の場合他機関類型に比べて非公式的な権利保護比率が39.7%と相対的に高い比重を占めている。



[図 3.24] 発明件数対出願比率及び非公式的な権利保護の比率

現在国内知的財産の保護水準⁶⁶と関連して今後更なる強化が必要があると答えた比率が全体の 86.0%(86.4%)となっている([図 3.25])。特に、大幅な強化が必要であるという意見が全体の 16.2%を占めている。機関類型別では、国内知的財産の保護水準を強化する必要があると答えた比率が政府出捐(研)の場合 95.2%に達している。一方、その他公共(研)の場合 74.2%と最も低い。



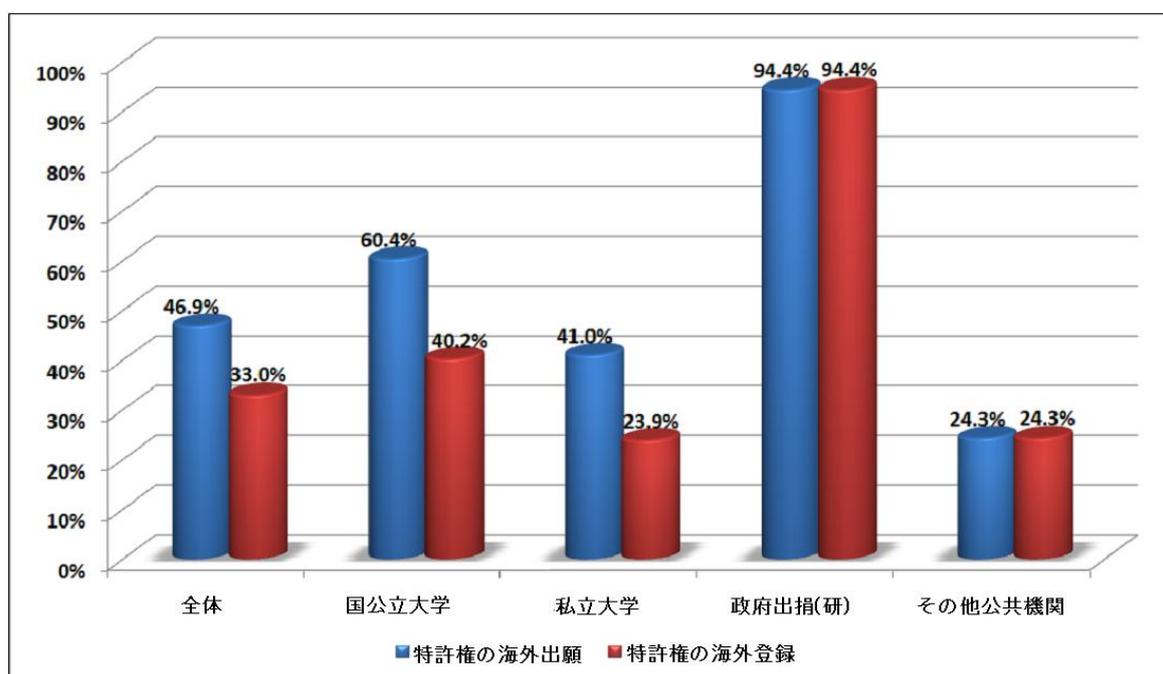
[図 3.25] 現在国内知的財産保護水準に対する認識

⁶⁶ 知的財産の保護水準は特許制度のように創出された知的財産に権利を付与するシステムが効率的に運営されているかどうかと、これを通じて成立された知的財産権が他人によって侵害された時にそれに対抗できる効率的な行政的・司法的措置が如何に整えられているかを意味する。

3.産業財産権の海外出願・登録及び国内出願計画

国内大学、公共研究機関のうち 2011 年に 1 件以上の特許権を海外に出願(PCT を含む)した機関は 46.9%(48.3%)となっている([図 3.26])。また、1 件以上の特許権を個別国家に登録した機関は 33.0%(33.8%)を占めている。特許権の他にデザイン権と商標権を海外出願した比率は各々 0%(同一)と 0.5%(0.6%)となっている。政府出捐(研)の場合特許権を海外に出願した比率が 94.4%と最高で、その他公共研究機関が 24.3%と最低となっている。

個別国家に出願された特許件数の全体機関平均は 15.6 件(16.1 件)⁶⁷、平均登録件数は 7.7 件(8.0 件)となっている。機関類型別では政府出捐(研)が 110.9 件、国公立大学が 11.8 件、私立大学が 6.0 件、その他公共(研)が 0.4 件を海外出願している。また、平均 PCT 出願件数は 5.9 件(6.2 件)となっている。機関類型別では政府出捐(研)が 16.0 件、国公立大学が 9.2 件、私立大学が 4.7 件、その他公共研究機関が 0.7 件となっている。



[図 3.26]特許権の海外出願/登録機関の比重

⁶⁷ 同じ産業財産権を複数の国家に個別に出願または登録した場合はそれらを全て合算している。例えば、Aという特許を米国、日本、ドイツに個別に出願または登録した場合、出願または登録件数は3と計算している。

大学及び公共(研)の知的財産担当者が予想する 2012 年対比 2013 年の知的財産権国内出願と関連し、全体の 58.9%が特許権の出願が増加すると答え、縮小すると答えた比率 2.1%に比べて非常に高くなっている([表 3.6])。機関類型別では、国公立大学が 63.3%と最も高く、政府出捐(研)が 44.8%と最も低い。また、政府出捐(研)は特許出願が縮小すると答えた比率が 11.2%と他機関類型に比べて非常に高くなっている。特許権の他の実用新案、デザイン、商標の出願が増加すると答えた比率は 21.8%、26.0%、25.0%となっている。

[表 3.6]2012 年対比 2013 年知的財産権の出願計画

		全体	国公立大学	私立大学	政府出捐(研)	その他公共(研)
特許	縮小	2.1%	6.7%	0.0%	11.2%	0.0%
	拡大	58.9%	63.3%	59.5%	44.8%	59.7%
実用新案	縮小	3.3%	10.1%	0.9%	11.2%	0.0%
	拡大	21.8%	26.6%	23.8%	11.2%	12.9%
デザイン	縮小	4.0%	3.4%	5.6%	0.0%	0.0%
	拡大	26.0%	26.6%	27.4%	22.4%	21.0%
商標	縮小	1.1%	3.4%	0.9%	0.0%	0.0%
	拡大	25.0%	30.0%	25.6%	28.0%	12.9%

国内出願の増減に影響を及ぼす要因として大学及び公共(研)全体の 58.6%が機関の産業財産権戦略の変化⁶⁸が及ぼす影響が大きいを答えている([表 3.7])。また、研究開発投資または予算の増減による研究成果の変化と市場及び技術競争環境の変化が重要であると選択した比率は各々 58.5%と 56.8%と続いている。一方、国内及び世界の景気変動が影響を及ぼす要因が重要であると選択した比率は 31.8%に過ぎず、大体外部の環境的な要因よりは機関内部的な要因が機関の出願件数の変化に与える影響がより大きいと見られる。

[表 3.7]産業財産権の国内出願の増減に影響を及ぼす要因

⁶⁸ 量または品質中心の知的財産出願戦略、維持費用対比収益性の変化など

影響を及ぼす要因	全体	国公立 大学	私立 大学	政府 出捐(研)	その他 公共(研)
研究開発投資または予算の増減による 研究成果の変化	58.5%	80.3%	51.5%	56.0%	64.6%
機関の産業財産権戦略の変化	58.6%	76.7%	53.1%	72.0%	51.6%
産業財産権に対する成果評価の比重変化 または評価方向の変化 ⁶⁹	54.7%	66.7%	51.1%	60.8%	51.6%
市場及び技術競争環境の変化	56.8%	60.0%	54.4%	72.8%	53.2%
国内及び世界の景気変動	31.8%	36.7%	32.7%	33.6%	19.3%
産業財産権の出願環境の改善及び 支援制度の強化	55.9%	60.0%	58.9%	60.8%	32.2%

4.産業財産権の出願・審査・維持費用及び関連規定の状況

国内大学及び公共(研)は 2011 年の 1 年間知的財産の出願・審査・維持に平均 3 億 3,512 万ウォンを支出している([表 3.8])。機関類型別では、政府出捐(研)が 17 億 4,852 万ウォンと最も多く、国公立大学が 3 億 2,000 万ウォン、私立大学が 1 億 8,059 万ウォン、その他公共研究機関が 7,114 万ウォンを支出している。政府出捐(研)の場合は他機関類型とは異なり、国内出願・審査費用より海外出願・審査費用をより多く支出している。

[表 3.8]知的財産の出願・審査・維持費用

	国内	海外	出願・審査・維
--	----	----	---------

⁶⁹ 論文などその他成果対比産業財産権実績の評価比重の拡大または縮小、量的成果評価の止揚及び質的成果評価の指向など

	出願・審査	維持	出願・審査	維持費用	持 費用の合計
全体	1億 4,784万ウォン	6,573 万ウォン	1億626 万ウォン	1,529 万ウォン	3億 3,512万ウォン
国公立 大学	1億 7,489万ウォン	7,280 万ウォン	6,292 万ウォン	939 万ウォン	3億 2,000万ウォン
私立 大学	8,749 万ウォン	4,105 万ウォン	4,289 万ウォン	916 万ウォン	1億 8,059万ウォン
政府 出捐(研)	6億 6,032万ウォン	2億 6,445万ウォン	7億 3,895万ウォン	8,480 万ウォン	17億 4,852万ウォン
その他 公共(研)	4,066 万ウォン	1,978 万ウォン	863 万ウォン	207 万ウォン	7,114 万ウォン

5.効果的な知的財産保護のために必要な政策支援

国内大学及び公共(研)は効果的に知的財産を保護するため「出願前または出願後の知的財産評価費用の支援」と「産業財産権の出願と登録にかかる費用の減免」が必要であると答えた比率が各々79.5%と74.7%と高い([表 3.9])。

特に、「企業などとの共同・委託研究契約の際に不平等契約防止のためのガイドラインの制定及び広報」が必要と答えた比率は国公立大学の場合86.8%と、他の機関と違って企業との研究契約を締結する際に直面する困難が相対的に大きいことを意味する。「出願前または出願後の知的財産評価費用の支援」が必要と答えた比率は国公立大学と私立大学、政府出捐(研)の場合各々86.8%と81.4%、78.4%とその他公共研究機関に比べて比較的が高い。

[表 3.9]効果的な知的財産保護のための政策支援の必要性

	全体	国公立	私立	政府	その他

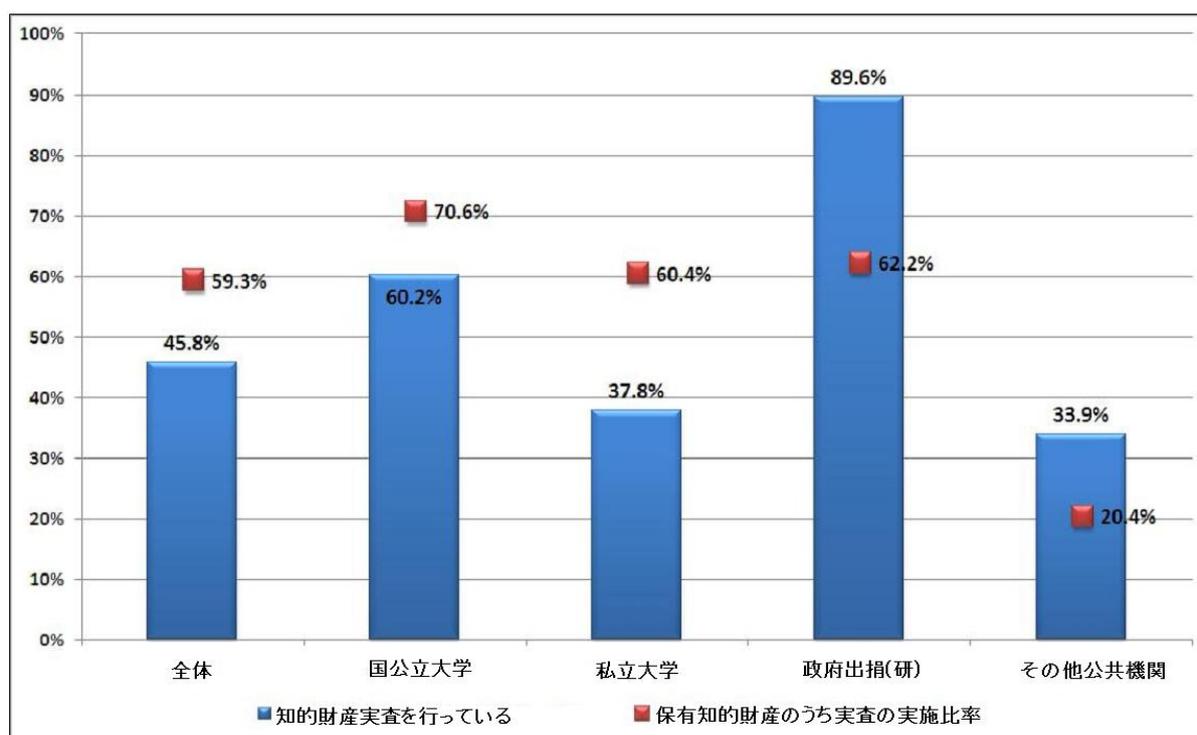
		大学	大学	出捐(研)	公共(研)
産業財産権の出願と登録にかかる費用の減免	74.7%	80.3%	76.4%	78.4%	56.5%
海外出願関連情報の提供	53.5%	73.4%	47.8%	66.4%	45.1%
企業などとの共同・委託研究契約の際、不平等契約防止のためのガイドラインの制定及び広報	69.3%	86.8%	66.3%	60.8%	66.1%
出願前または出願後の知的財産評価費用の支援	79.5%	86.8%	81.4%	78.4%	61.3%

注. (%)は5点尺度(1:必要性が最も低い、5:必要性が最も高い)で[(4点と5点と答えた企業数)/(総回答機関数)]×100(%)

第4節 知的財産の活用

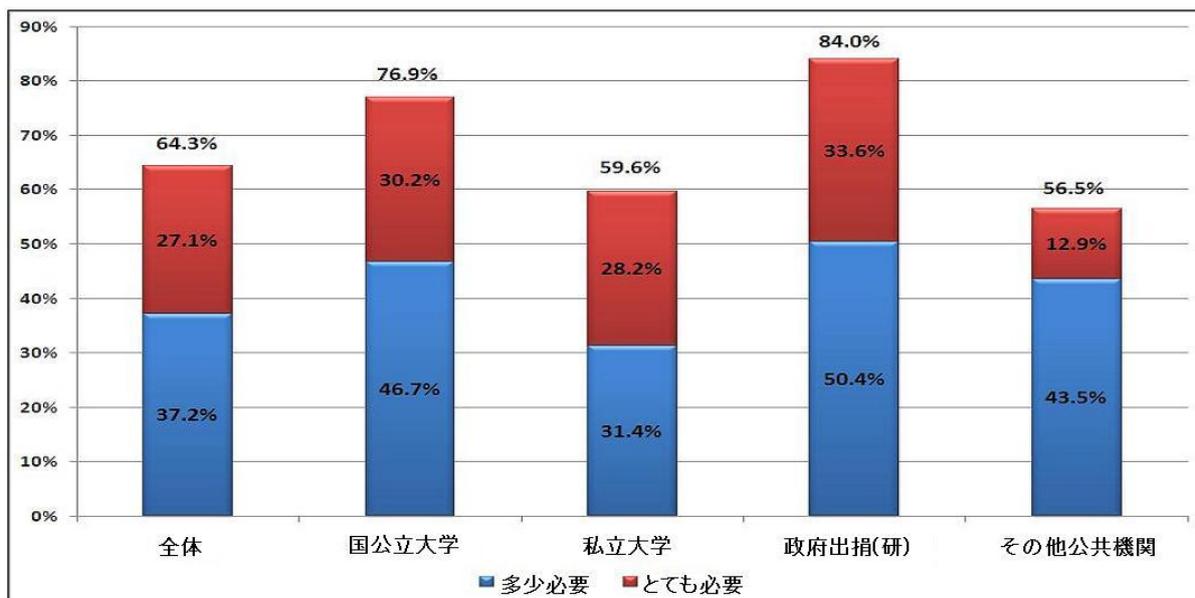
1.知的財産実査

保有知的財産に対する実査(評価)を行っている大学、公共(研)の比率は 45.8% (46.3%)となっており、保有する知的財産のうち 59.3%(58.8%)に対して実査を行っている([図 3.27])。機関類型別では、政府出捐(研)の場合知的財産実査を行っている比率が 89.6%と最も高いが、保有する知的財産のうち実査の実施比率は 62.2%と全体平均より若干高い水準である。一方、国公立大学の知的財産実査の実施比率は 60.2%となっているが、保有する知的財産のうち実査の実施比率は 70.6%と最も高い。



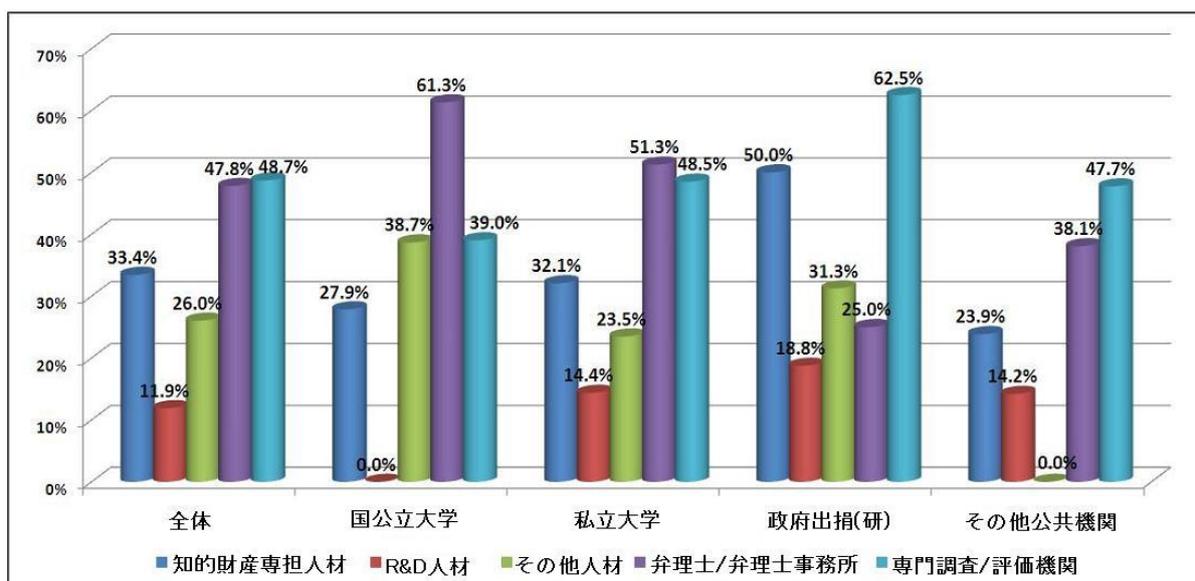
[図 3.27]知的財産実査の実施状況

国内大学及び公共(研)の 64.3%(64.0%)は知的財産に対する実査が必要またはとても必要であると答えている([図 3.28])。これは実際行っている比率である 45.8%に比べて高い。知的財産実査の必要性に対して肯定的に回答した比率は国公立大学と政府出捐(研)が各々76.9%、84.0%と高い。特に、政府出捐(研)の 33.6%が知的財産に対する実査がとても必要であると答えている。



[図 3.28]知的財産実査の必要性

一方、知的財産の実査を行っている場合、弁理士・弁理士事務所や専門調査・評価機関に依頼すると答えている比率が各々47.8%(49.0%)と48.7%(49.1%)と最も高い([図 3.29])。これは先行特許調査及び予備評価とは違って知的財産実査の場合主に外部人材が実施していることを意味する。特に、専門調査・評価機関に依頼すると答えている比率は政府出捐(研)の場合62.5%と最も高い。また、研究開発人材が直接実査を行っているとした比率は11.9%(12.0%)に止まっている。

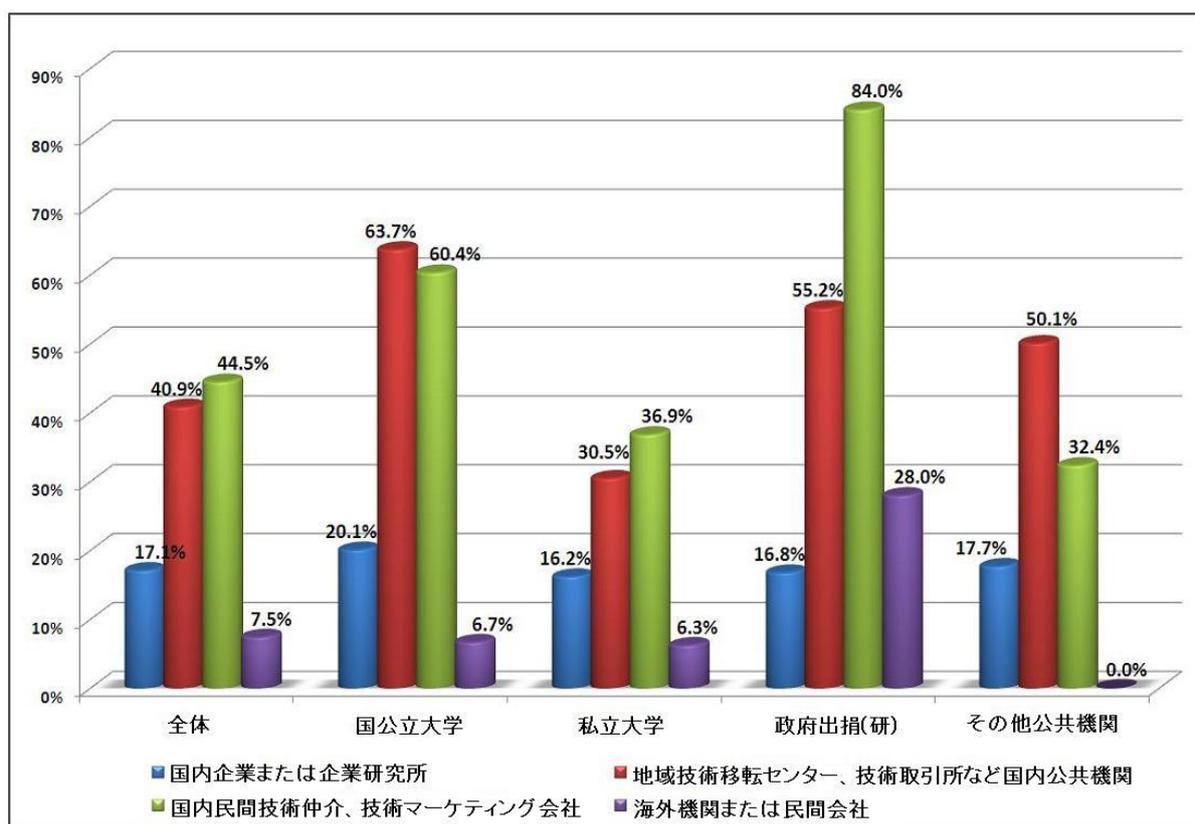


[図 3.29]知的財産実査を行っている場合、その実施人材

注. 複数回答

2.知的財産の活用戦略

最近 3 年間技術取引機関に業務を依頼した比率を見ると、大学及び公共(研)の場合平均 44.5%が国内民間技術仲介、技術マーケティング会社に業務を依頼したり、業務協約を締結している。また、地域技術移転センター、技術取引所など国内公共機関に関連業務を依頼した比率は 40.9%となっている([図 3.30])。政府出捐(研)と国公立大学の場合、国内民間技術仲介、技術マーケティング会社に依頼する比率が各々 84.0%、60.4%と最も高く、国公立大学と政府出捐(研)の場合は地域技術移転センターなど国内公共機関に依頼した比率が各々 63.7%、55.2%と最も高い。

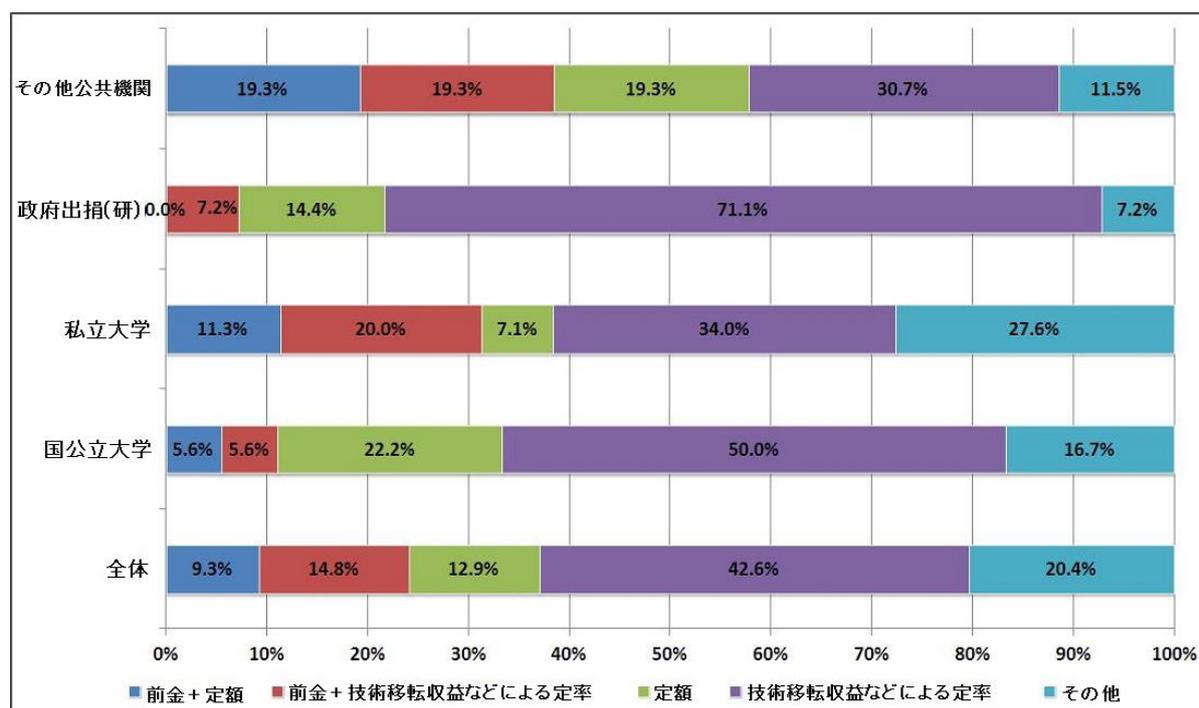


[図 3.30]最近 30 年間技術取引機関への業務依頼及び締結状況

技術取引機関などに業務を依頼する場合の主な費用支払い方法として、全体の 42.6%(42.4%)が技術移転収益などによる定率で計算した成功報酬と答えている([図 3.31])。特に、政府出捐(研)の 71.1%(同一)が該当費用支払い方法を選択している。こ

のような結果は、企業の場合このような費用支払い方法を選択した比率が 10.5%と最も低いことを考えると、企業と大学・公共(研)間技術移転取引の際に好む費用支払い方法にかなり違いがあることを意味する。

その他に調査・マーケティング費用など活動費(前金)と技術移転収益などによる定率が結合した形態を選択した比率は 14.8%となっている。このような費用支払い方法は他機関に比べて私立大学の選好度が 20.0%と相対的に高い。



[図 3.31]技術取引機関などに業務を依頼した場合の主な費用支払い方法

[表 3.10]は国内技術取引システムに対する活用状況を示している。技術移転、取引のために IP-mart など国内オンライン技術取引システムを実際活用している機関の比率は全体の 45.6%(47.2%)となっている。特に政府出捐(研)及び国公立大学でのオンライン取引システムの活用比率が各々 83.2%や 70.2%と高い。しかし、実際活用している機関のうち該当システムの活用度が高いと認識している比率は 27.5%(同一)に止まっている。

また、技術移転及び取引のために特許技術移転博覧会など国内オフライン取引システムを活用している比率は 46.2%となっており、オンライン取引システムを活用する

比率と大きな違いは見られない。しかし、実際活用している機関のうち該当システムの活用度が高いと答えた比率は 39.1%とオンラインシステムより多少高いことがわかる。

一方、yet2.com など海外オンライン取引システムを活用している比率は 20.9%となっているが、該当システムの活用度が高いと答えた比率は 2.0%と活用度そのものは低い水準であることがわかる。また、海外オフライン取引システムもまた活用比率は 19.2%となっているが、活用度が高いと答えた比率は 4.3%となっており、差が出ている。

[表 3.10]国内技術取引システムの活用度

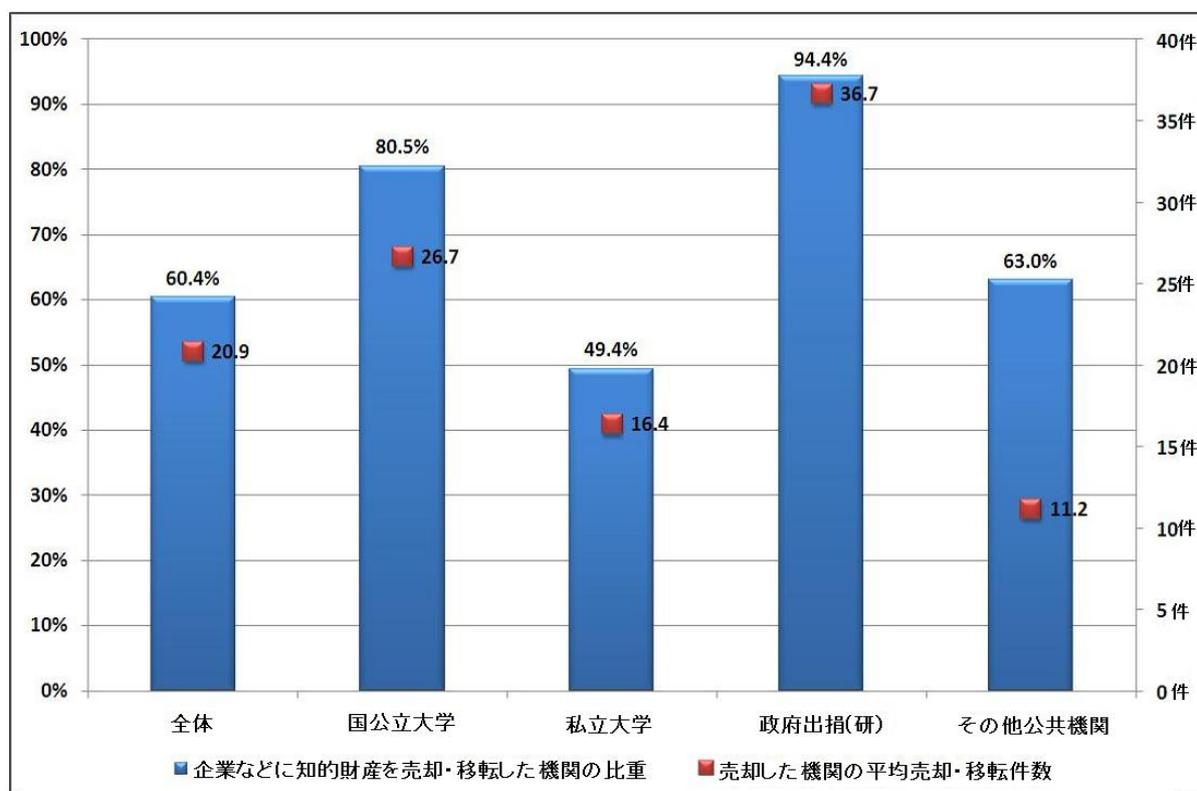
		全体	国公立 大学	私立 大学	政府 出捐(研)	その他 公共(研)
国内オンライン 取引システム	活用機関	45.6%	70.2%	33.1%	83.2%	46.8%
	活用度が比較的に高い	27.5%	41.4%	14.6%	41.2%	14.3%
国内オフライン 取引システム	活用機関	46.2%	66.9%	35.9%	88.8%	38.7%
	活用度が比較的に高い	39.1%	55.6%	36.5%	47.4%	0.0%
海外オンライン 取引システム	活用機関	20.9%	26.6%	15.1%	55.2%	17.7%
	活用度が比較的に高い	2.0%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%
海外オフライン 取引システム	活用機関	19.2%	23.3%	13.2%	55.2%	17.7%
	活用度が比較的に高い	4.3%	0.0%	5.3%	8.3%	0.0%

注. (%)は 5 点尺度(1:活用度が低い、5:活用度が高い)で[4 と 5 と答えた企業数]/(活用した経験のある企業数)×100(%)、母集団推定値

3.知的財産権の売却・移転及び活用状況

2011年の1年間1件以上の知的財産を企業などに売却または移転した大学及び公共(件)の比率は全体の60.4%(61.6%)となっており、知的財産を売却または移転した大学、公共(件)の平均売却・移転件数は20.9件⁷⁰(21.1件)となっている([図 3.32])。

機関類型別では、政府出捐(研)の94.4%が平均36.7件の知的財産を売却・移転し、国公立大学の80.5%が平均26.7件の知的財産を売却・移転している。一方、海外に1件以上の知的財産を売却・移転した機関の比率は全体の6.5%(6.8%)となっている。



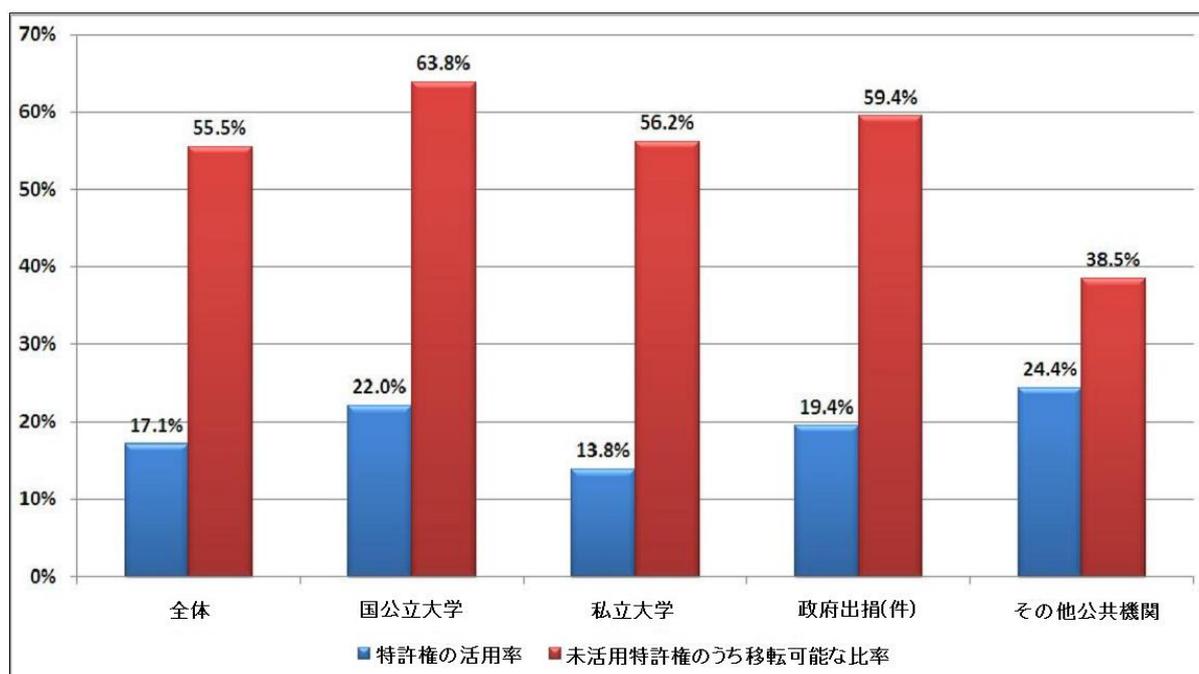
[図 3.32]知的財産を売却・移転した機関の比率及び件数

大学及び公共(研)が2011年産業財産権を有償実施許与または売却することで得た金銭的成果は平均2億9,398万ウォンとなっている。機関類型別では、政府出捐(研)の平均が13億7,264万ウォンと他機関に比べて高い。また、ノウハウだけを実施許与し

⁷⁰ 全体機関平均としては12.7件

たり、売却することで得た成果は平均 1 億 5,408 万ウォンで、政府出捐(研)の平均は 9 億 1,783 万ウォンとなっている。

大学、公共(研)が保有する特許権のうち外部の他機関に移転されたり、実験室創業、研究員創業などに活用された比率である活用率⁷¹は平均 17.1%(17.4%)となっている([図 3.33])。特許活用率はその他公共研究機関と国公立大学、政府出(研)が各々24.4%、22.0%、19.4%の順となっており、私立大学の場合は 13.8%となっている。しかし、このような活用率は機関の全体保有件数のうち現在活用されている産業財産権の件数を示すものであり、現在は活用されていないものの今後活用可能性が高い産業財産権が多いと予想される。調査の結果、未活用特許の中で他機関に移転可能な比率は全体保有件数の 55.5%となっている。機関類型別では、国公立大学は 63.8%、政府出捐(研)は 59.4%、私立大学は 56.2%と続いている。



[図 3.33]特許権の活用率

⁷¹ 企業の場合生産活動や技術移転などには直接活用していないが、戦略的な目的(核心技術の防御、特許訴訟防止、国家レベルでの必要性など)で保有・活用している特許が存在するため、これを反映して活用率と事業化率を区分するが、大学、公共研究機関の場合はこのような差が殆どないため活用率と事業化率を同じ意味で使うことにする。

4.効果的な知的財産活用のために必要な政策支援

国内大学及び公共(研)の効果的な知的財産活用のための政策支援として技術移転関連のマーケティング及びコンサルティング支援が必要と答えた比率は全体の 80.6%を占め、最も高い([表 3.11])。保有特許技術に対する価値評価支援が必要と答えた比率も 75.3%と続いている。

機関類型別では、技術移転関連のマーケティング及びコンサルティング支援が必要と答えた国公立大学と政府出捐(研)、その他公共研究機関は各々90.1%、83.2%、82.3%の順となっており、保有特許技術に対する価値評価の支援が必要と答えた国公立大学とその他研究機関、政府出捐(研)は各々83.4%、79.0%、77.6%の順となっている。

[表 3.11]効果的な知的財産活用のための政策支援の必要性

	全体	国公立 大学	私立 大学	政府 出捐(研)	その他 公共(研)
保有特許技術に対する価値評価の支援	75.3%	83.4%	72.0%	77.6%	79.0%
新技術の事業化のための研究所企業・ 実験室創業支援	59.3%	66.9%	58.8%	61.6%	49.9%
特許技術の取引、流通システムの改善	69.1%	80.1%	63.6%	78.4%	74.2%
技術移転関連のマーケティング及び コンサルティング支援	80.6%	90.1%	77.3%	83.2%	82.3%
優秀技術の輸出支援	60.6%	66.9%	60.2%	78.4%	41.8%

注. (%)は 5 点尺度(1：活用度が低い、5：活用度が高い)で[4 と 5 と答えた企業数]/(総回答機関数)]×100(%)

第5節 知的財産の侵害及び紛争

1. 知的財産権の侵害及び事後対応

母集団に属する 238 の大学及び公共(研)のうち 1.6%(同一)に該当する 4 つの機関⁷²が 2011 年に知的財産権の侵害を受けたと答えている。⁷³全体侵害事例は全て特許権侵害である。

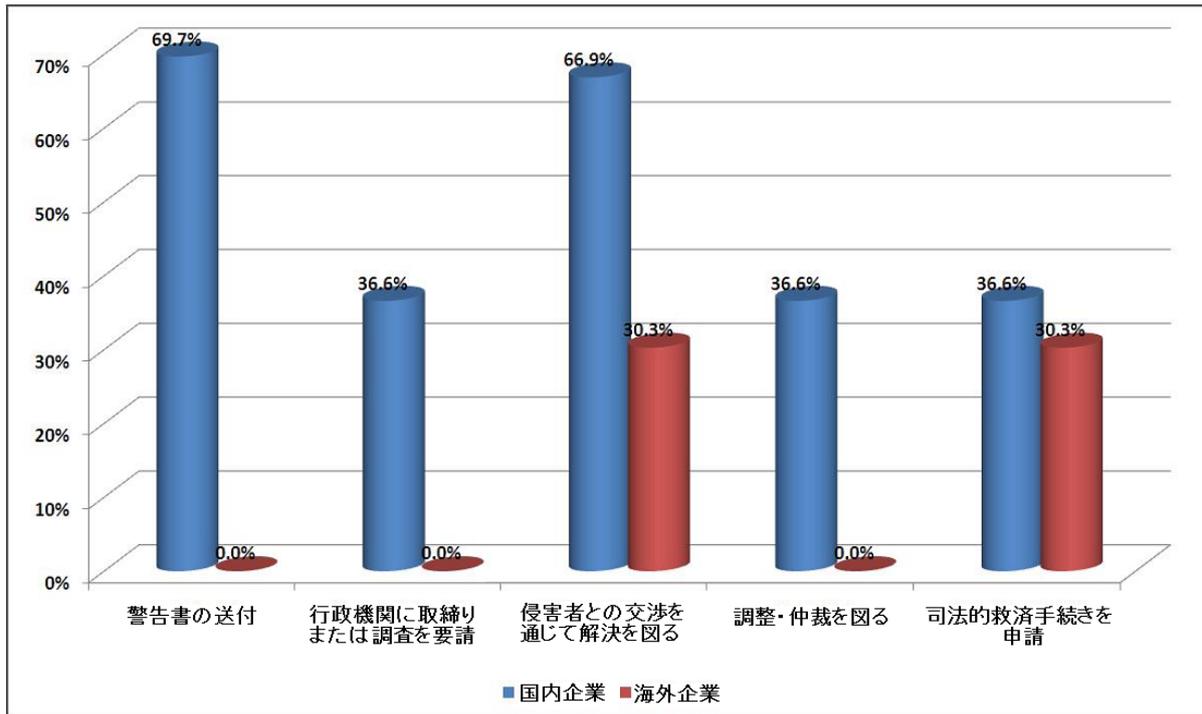
侵害事例 4 件のうち侵害製品の製造者が海外企業である場合は 30.3%、国内企業である場合は 100%となっている。侵害製品の製造地域及び流通地域は国内 100%、海外 30.3%となっている。また、侵害製品の流通類型は、63.4%がインターネット及びホームショッピングなどを通じたオンライン流通で、オフライン流通は 100%となっている。侵害事例 4 件のうち民事訴訟を通じて損害賠償額が認められたり、当事者間で和解が成立した場合は 2 件で、損害賠償額または和解金が 1 億ウォン未満と 30 億ウォン以上と答えている。

知的財産権侵害以後の事後対応として、知的財産権の侵害を受けた 4 つの機関のうち国内企業に警告書を送付した場合は全体の 69.7%となっている。また、侵害者との交渉を通じて解決を図った場合は 66.9%、行政機関に取締りまたは調査を要請した場合は 36.6%、調整及び仲裁を図る、司法的救済手続き申請の比率はいずれも各々 36.6%となっている。一方、警告書の送付から侵害訴訟の完了時までにかかった費用⁷⁴は平均 336 万ウォンとなっている。

⁷² 私立大学3機関、政府出捐(研)1機関

⁷³ 大学及び公共(研)の知的財産権侵害調査はこれまで行われたことがない。また、知的財産権の侵害による営業上の被害がないために実際に侵害された比率より知的財産管理担当者が認知している比率が極めて少ないことを考慮する必要がある。

⁷⁴ 損害賠償額または和解金額を除く。



[図 3.34]知的財産権侵害への事後対応

2.知的財産権紛争関連の難点及び必要な政策支援

知的財産権侵害対応における難点として、対応の際に過剰な時間と費用がかかる点が最も大きな問題として指摘されている([表 3.12])。また、該当国家における知財権法規など関連知識の習得が難しい点と言語・地理的距離などの環境によって紛争相手との交渉が難しいという点も難点として挙げられた。

一方、他機関の知財権を侵害して紛争が発生した時の対応における難点も同じく、対応の際に過剰な時間と費用がかかる点が最も大きい。また、内部人材の専門性不足、該当企業及び国家の知財権関連事項に対する情報不足によって対応が難しいと答えた比率も高くなっている。

[表 3.12]知的財産権侵害への対応における難点

		程度が極めて高い
--	--	----------

知財権侵害被害 に対応する際の 難点	言語・地理的距離などの環境で紛争相手と交渉が難しい	23.4%
	該当国家における知財権法規など関連知識の習得が難しい	27.8%
	該当国家の行政的・司法的救済手続きが不備である	19.5%
	該当国家政府の態度が非協力的である	16.2%
	対応時に過剰な時間と費用がかかる	43.6%
他機関知財権侵 害紛争時の難点	法律代理人の選定が難しい	9.3%
	内部人材の専門性不足	31.5%
	対応関連の政府支援政策に対する情報不足	20.6%
	該当企業及び国家の知財権関連事項に対する情報不足	23.6%
	対応時に過剰な時間と費用がかかる	44.9%

最後に、知的財産権侵害に対応するために必要な政府政策として、国内大学及び公共(研)の 37.1%が知的財産権侵害対応のための訴訟など費用支援がとても必要と答えており、最も高くなっている。また、実効性のある行政的・司法的処罰措置の強化と知的財産権の保護及び対応活動のための情報提供がとても必要と答えた比率も同じく 28.0%と高い。

[表 3.13]知的財産権侵害に対応するために必要な政策支援

政府政策	とても必要
実効性のある行政的・司法的処罰措置の強化	28.0%
国境措置対象の知的財産権範囲の拡大、侵害物品の国内流入の遮断	23.2%
知的財産権の保護及び対応活動のための情報提供	28.0%
行政機関の知的財産権侵害製品取締り権限の強化	25.3%
知的財産権侵害製品などに対する通報褒賞金額の増額	26.3%
知的財産権侵害対応のための訴訟など費用支援	37.1%

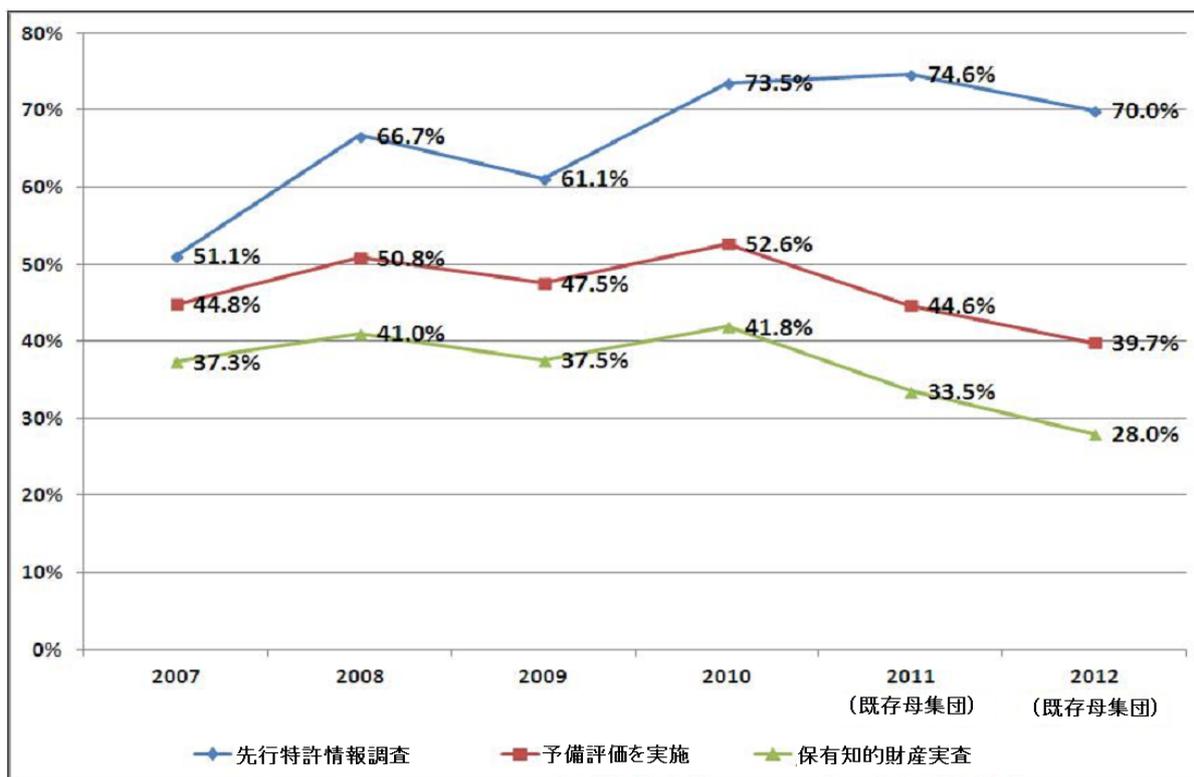
第4章 2012年韓国知的財産活動の診断

本章では知的財産活動の主要項目別・年度別比較を通じて、国内企業及び大学・公共(研)の知的財産インフラ、創出、権利化及び保護、活用、侵害及び紛争の段階別活動がどのような方向に変化しているかを提示している。また、2011年と2012年の既存母集団の結果を算出して比較しやすくしており、2011年と2012年調査に全て回答した企業255社を分析⁷⁵して2011年と2012年知的財産活動主要指標の変化が統計的に有意なのかどうかを調査している。

1.知的財産先行活動の変化

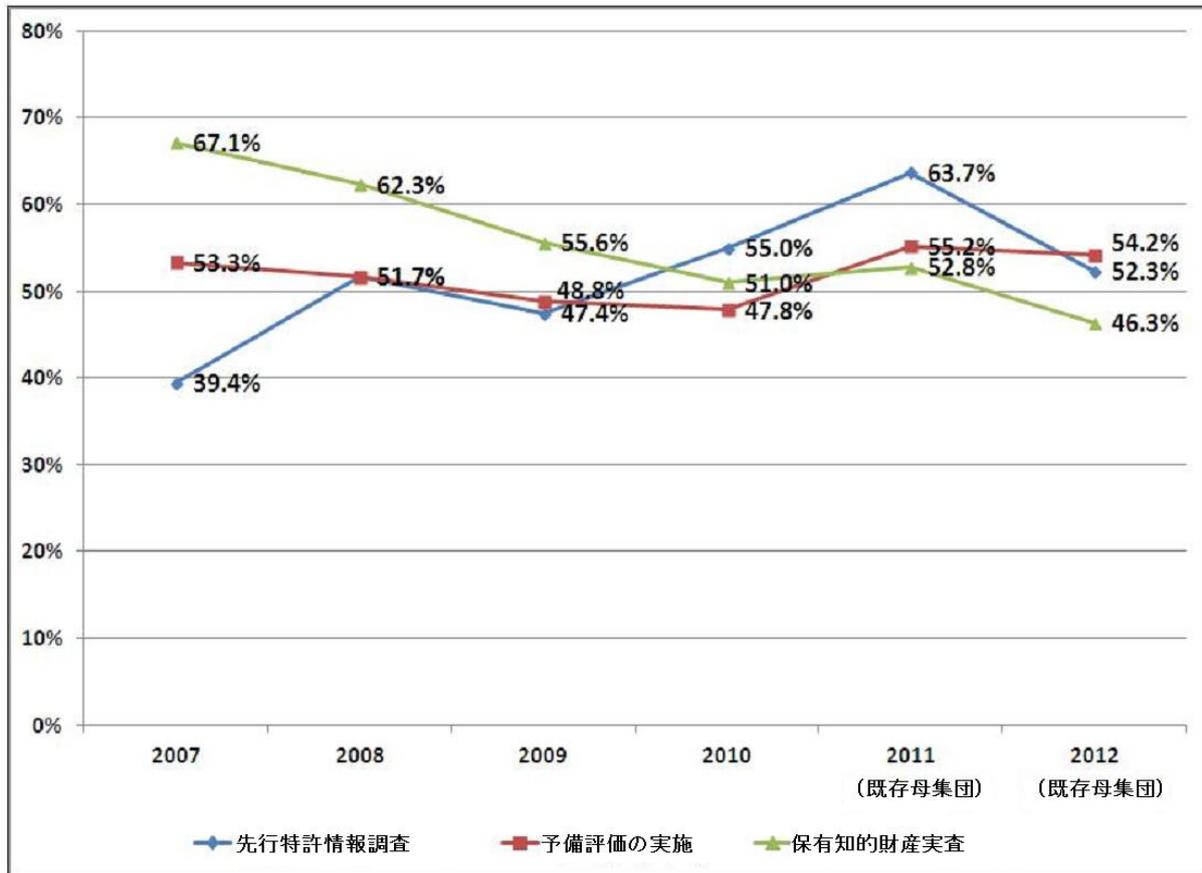
各特許先行活動(先行特許調査、出願前の予備評価、保有知的財産に対する実査)を行っていると考えている企業比率の年度別推移は[図 4.1]のとおりである。先行特許調査を行っている比率は2011年74.6%から2012年70.0%に減少しており、予備評価及び実査を行っていると考えた比率は2011年各々44.6%と33.5%から2012年39.7%と28.0%に減少している。企業の場合、先行特許情報調査を始め先行活動比率が2011年に比べて減少し、予備評価の実施及び保有知的財産実査の実施比率も同じく2010年以後減少傾向にある。先行特許情報調査の比率及び予備評価実施比率の減少は企業の戦略的な活動を通じて説明できる。一部企業の場合、出願日付を逸早く獲得するため優先出願した後にOA(Office Action)対応過程で主要問題を解決する方がより効率的であると判断し、戦略的に先行特許情報調査への支出を減らしてOA対応費用として使用する傾向も見られる。2011年と2012年重複回答企業を対象にt検定を行った結果、予備評価の実施比率は52.4%から52.8%に小幅増加となっているが、統計的に有意なものではないと分析できる。

⁷⁵ 知的財産活動実態調査の母集団は毎年母集団に含まれ、脱落する企業によって母集団の特性(出願件数及び産業分布)が毎年変わる可能性があるため、2011年、2012年重複回答企業を別途分析している。この時、独立t検定(independent t-test)を活用しているが、これは同一標本に対して時間による変化を検証する統計的な方法論である。



[図 4.1]企業の先行活動実施比率の推移

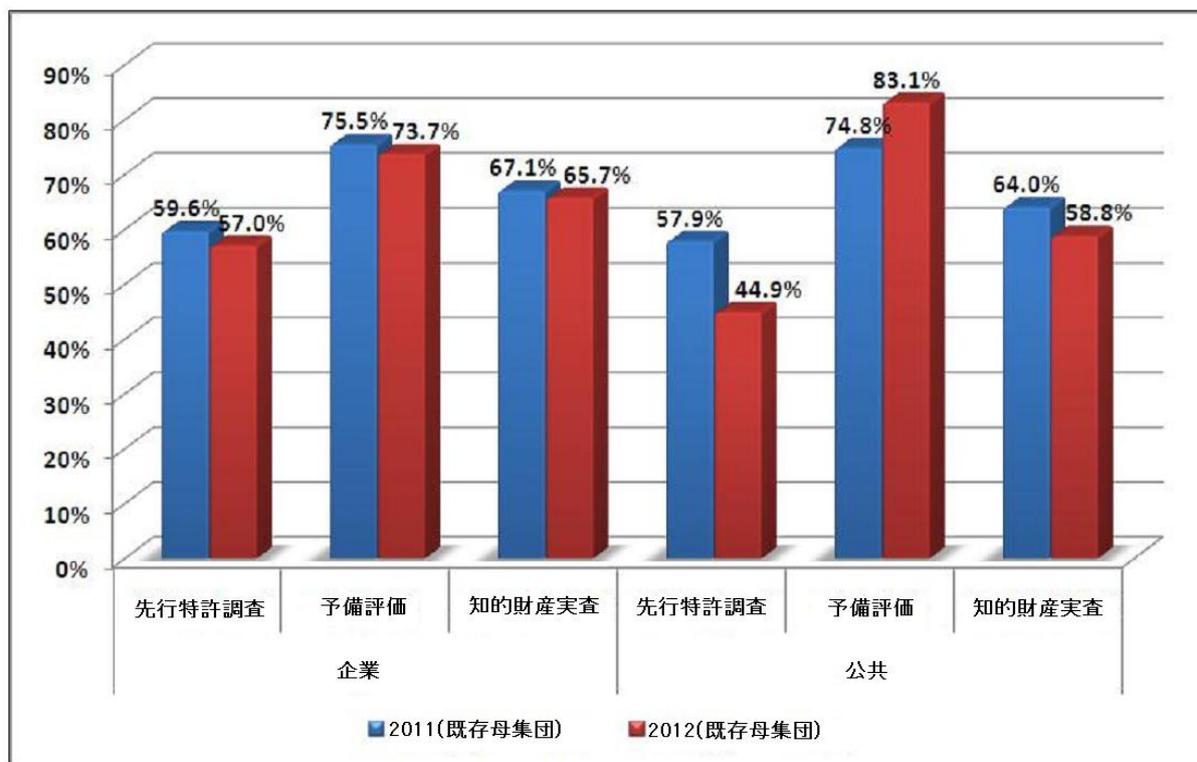
大学及び公共(研)の場合にも先行活動実施比率は 2011 年対比いずれも減少となっている。予備評価の場合は 2011 年 55.2%から 2012 年 54.2%に小幅減少しているものの同水準を維持している。一方、先行特許情報調査及び保有知的財産実査の場合は各々 2011 年 63.7%、52.8%から 2012 年 52.3%、46.3%に大幅減少している。このような先行活動実施の減少傾向は先行活動の場合特に自社内実施よりは外部人材を活用する活用度が高いために景気低迷と関連する費用削減レベルで発生したものと分析できる。また、研究企画段階で該当研究員または発明者個人が自主的に先行特許情報調査を行うことで機関レベルで積極的に介入しないケースが増加しているが、一方これを積極的に反映せず先行特許情報調査の実施比率が減少となっている可能性も高い。



[図 4.2]大学及び公共(研)の先行活動実施比率の推移

次に、全体研究開発課題において先行特許調査を行っている比率、全体発明件数のうち出願前に予備評価を実施する比率、保有知的財産のうち実査を行っている比率の年度別推移は[図 4.3]のとおりである。図からも分かるように、2012年調査では大学・公共(研)の全体発明件数のうち出願前の予備評価実施比率を除けば企業と大学・公共(研)における各実施比率が2011年に比べて減少している。企業の先行特許調査は戦略課題または核心課題に対してのみ選択的に行われる場合が多く、全体研究開発対比先行特許調査の活動比率が低くなっているものと判断される。企業の場合、重複回答分析の結果を見ると、全体発明件数のうち予備評価実施比率は統計的に有意ではないが、41.2%から42.8%に小幅増加している。大学・公共(研)の場合、機関レベルで行う先行特許情報調査が減少している。一方、知的財産担当組織で研究者たちが独自に行う先行活動の実施に対する正確な統計値を確保することは容易ではないために研究開発課題のうち先行特許調査を行う比率が低くなっているものと判断される。大学・公共(研)の全体発明のうち予備評価の実施比率は高くなっているが(2011年実施

比率 74.8%)、これは機関が徐々に予備評価に対する規定を整備し、研究審議委員会などを通じて該当発明の出願可否を判断する仕組みが定型化しつつあるために出た結果と見られる。

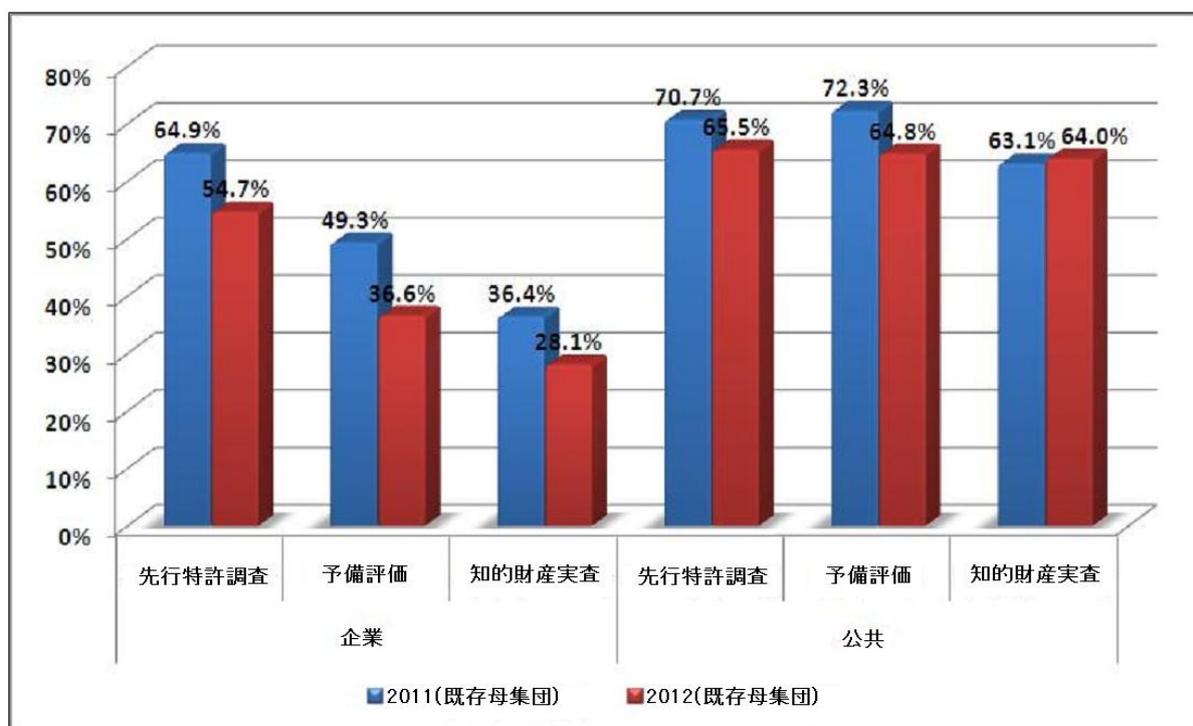


[図 4.3]全体研究開発課題、発明、保有知的財産のうち実施比率の変化

各先行活動が必要と認識している国内企業、大学・公共(研)の比率は[図 4.4]のとおりである。大学・公共(研)の知的財産実査に対する必要性認識度が 63.1%から 64.0%に小幅増加していることを除けば、必要性に対する認識もまたいずれも減少している。先行特許調査と予備評価の場合は企業と公共、いずれも昨年比減少しているが、特に企業においてより大幅な減少となっている。特に、企業の場合は最近技術ライフサイクルの短縮によって先行特許調査による費用負担が増加し、登録特許に対する調査の意味が減少することで先行特許調査に対する必要性に関して相反する見解が登場している。

特に、公共と比べる時に先行活動に対して企業が認識している必要性が低くなっているのは現在先行活動を行っている企業の比率が減少していることと関係があると言える。にもかかわらず先行特許調査の場合戦略的に研究開発の企画段階から進めるこ

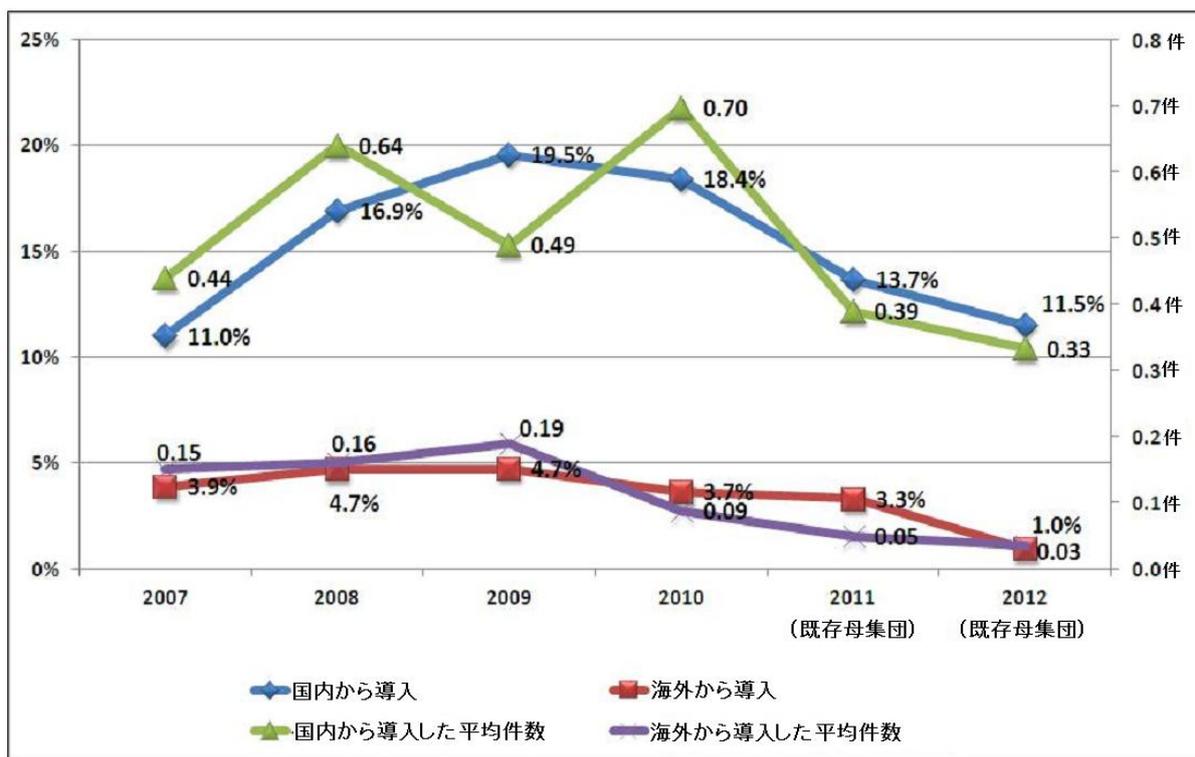
とで技術の重複を防止すると同時に、効率的な課題運営が誘導できるため極めて重要な過程である。したがって、まだ知的財産先行活動を全く行っていない企業を対象に先行活動の重要性に対する教育及び広報が求められる。



[図 4.4]先行活動の必要性に対する認識の変化

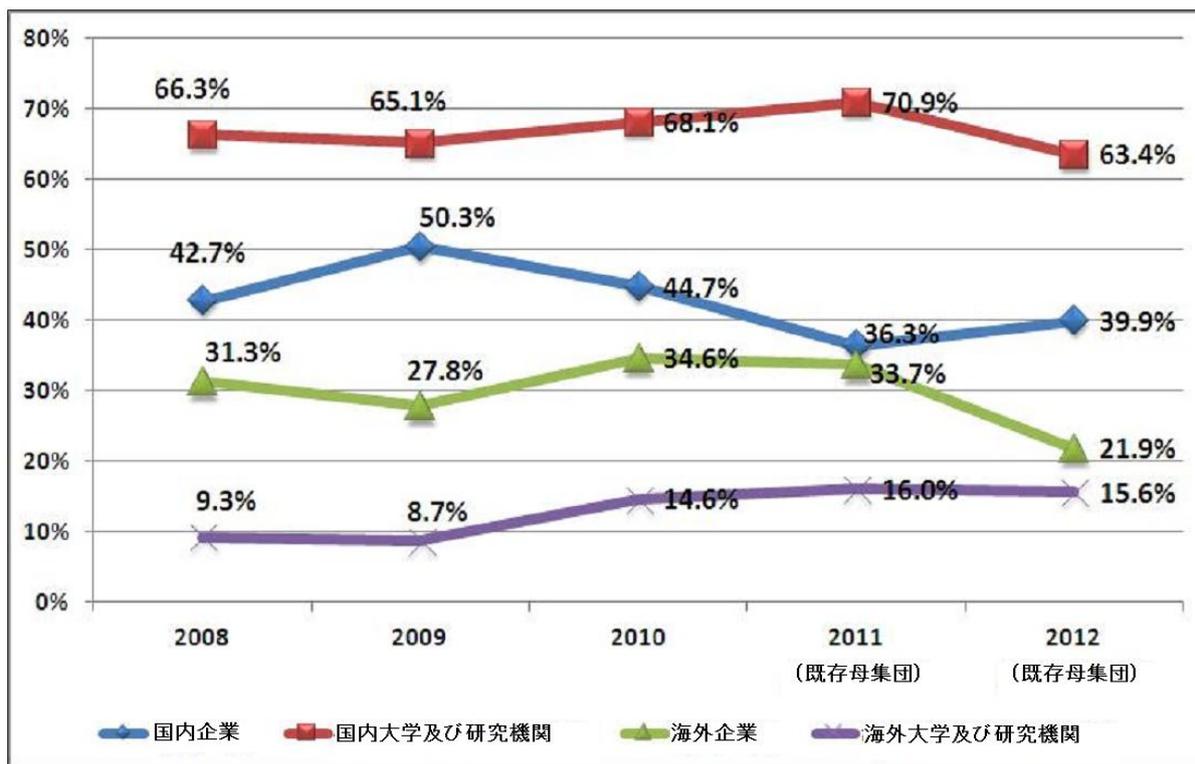
2.外部からの知的財産導入の減少

1年間企業外部から知的財産を導入した企業の比率は[図 4.5]のとおりである。図からも分かるように、2010年から国内と海外から知的財産を導入した企業の比率は引き続き減少傾向にある。特に、国内から知的財産を導入した企業の比重及び平均導入件数は2011年各々13.7%と0.39件から2012年11.5%と0.33件に減少している。海外から知的財産を導入している企業の比重及び平均導入件数もまた2011年各々3.3%、0.05件から2012年1.0%、0.03件に減少している。重複回答企業を分析した結果、統計的に有意な数値ではないが、国内導入企業の平均導入件数は1.0件から0.5件、海外導入企業の平均導入件数は0.3件から0.03件に減少している。



[図 4.5]知的財産導入の推移

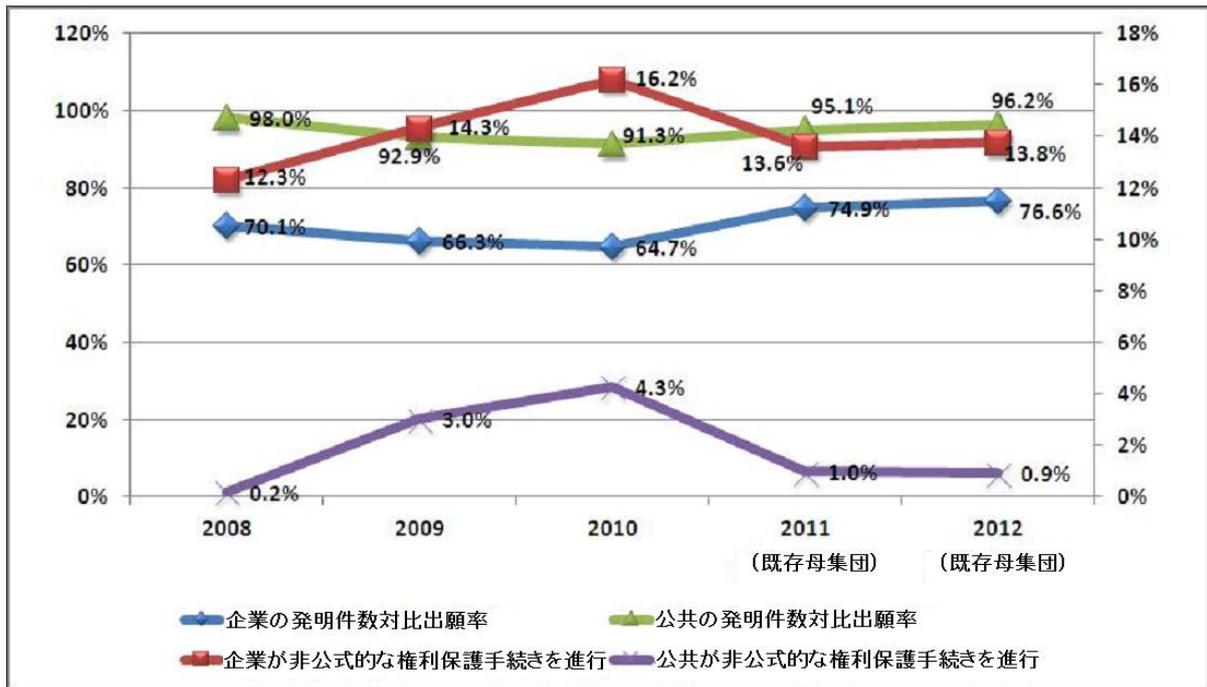
知的財産の導入を拡大すると答えた企業が導入を希望する技術の出处と関連した年度別の推移は[図 4.6]のとおりである。このうち、国内企業及び海外企業から知的財産を導入すると答えた比率は各々2010年 44.7%、34.6%から減少し、2011年調査では36.3%、33.7%と低くなっている。また、2012年調査では国内企業からの導入は39.9%に小幅上昇、海外企業からの導入は21.9%に減少している。一方、国内大学及び研究機関から知的財産を導入すると答えた比率は2011年に小幅上昇しているが、2012年に再び63.4%に減少している。一方、海外大学及び研究機関から知的財産を導入すると答えた比率は2009年から続けて小幅上昇となっており、2012年に小幅減少しているものの同水準を維持しているように見える。特に、単に技術や製品を作る中小企業の場合は外部技術の導入に財政上の限界があり、上位生産リンクの需要そのものに制限があるため、外部技術導入の必要性そのものが低い可能性があることを考慮しなければならない。



[図 4.6]知的財産導入の拡大方向の変化

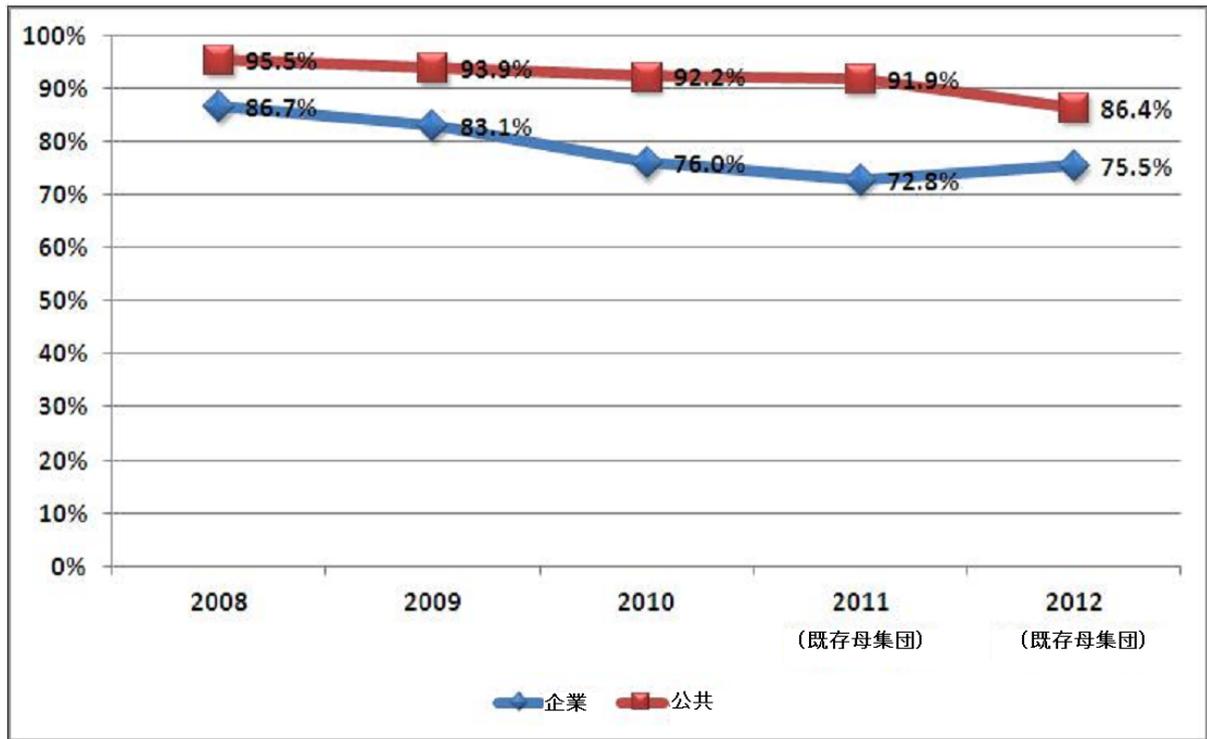
3.知的財産保護戦略としての出願比率の増加

研究開発の成果を保護するための戦略として全体発明件数のうち出願率と非公式的な保護手続きを進行する比率の推移は[図 4.7]のとおりである。企業の場合、2011 年対比 2012 年に発明件数対比出願率及び非公式的な手続きを進行する比率が各々 74.9%、13.6%から 76.6%、13.8%に小幅増加している。公共の場合は発明件数対比出願率は 2011 年 95.1%から 96.2%に増加しているが、非公式的な保護手続きを進行する比率は 2011 年 1.0%から 2012 年 0.9%に減少している。



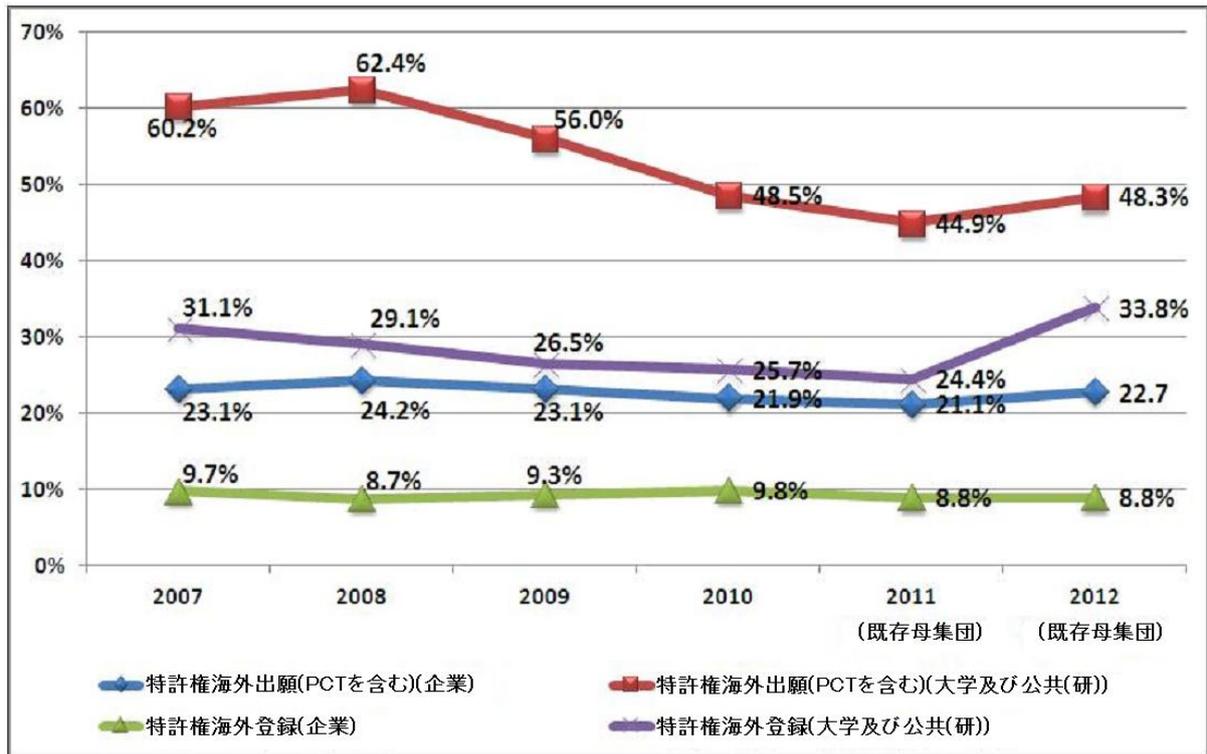
[図 4.7] 発明件数対比出願率の推移

国内知的財産の保護水準を強化する必要があると答えた企業と大学・公共(研)の比率は[図 4.8]のとおりである。図からも分かるように、大学・公共(研)の場合は国内知的財産の保護水準をより強化する必要があると認識している比率が着実に減少している。一方、企業の場合は 2011 年までその比率が着実に減少していたが、2011 年対比 2012 年に 72.8%から 75.5%に増加している。最近企業間の特許紛争が話題となったことから知的財産保護の必要性に対する企業の認識が高まっているものと解釈できる。



[図 4.8]国内知的財産保護水準の強化が必要

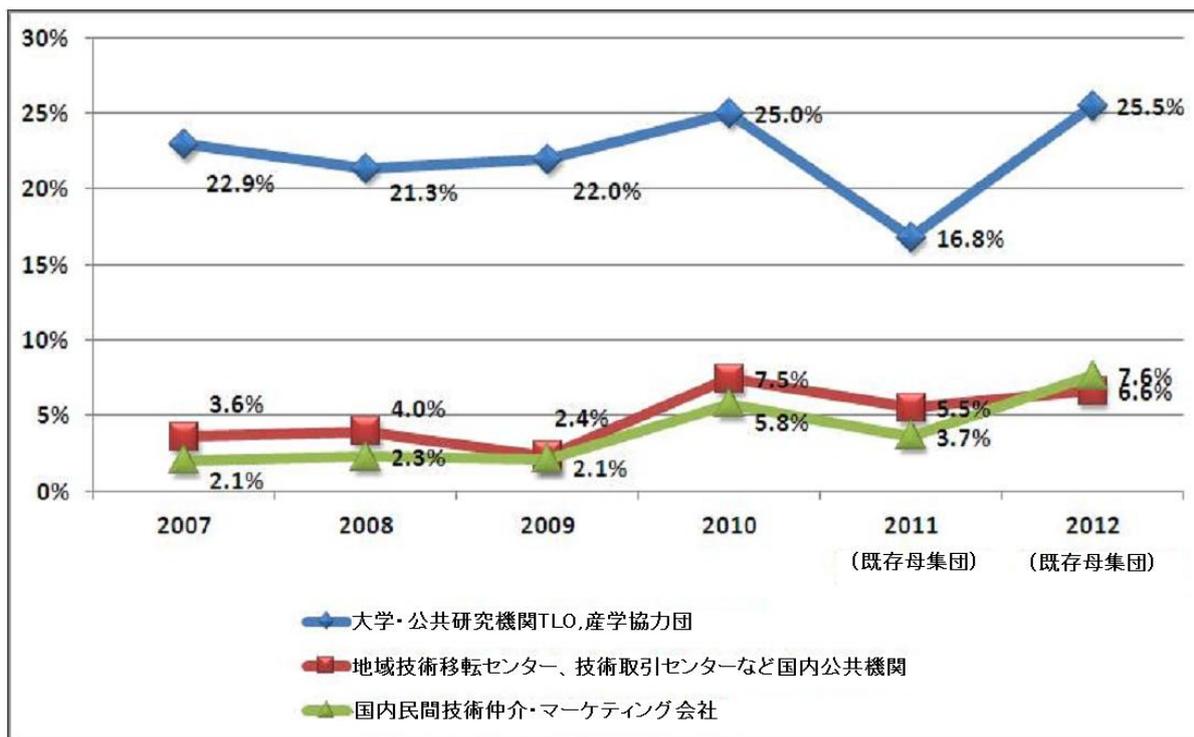
1年間海外に特許出願(PCTを含む)及び登録した企業、大学・公共(研)の比率推移は[図 4.9]のとおりである。企業の海外出願及び公共の海外出願比率は2011年対比2012年にいずれも小幅増加しており、企業の海外登録は同水準を維持している。公共の海外登録比率は2011年対比2012年に比較的に大幅増加している。2011年と2012年重複回答企業を対象に比較した結果、統計的に有意味ではないが、海外出願企業の比率が33.3%から35.1%に増加している。



[図 4.9]海外出願及び登録の推移

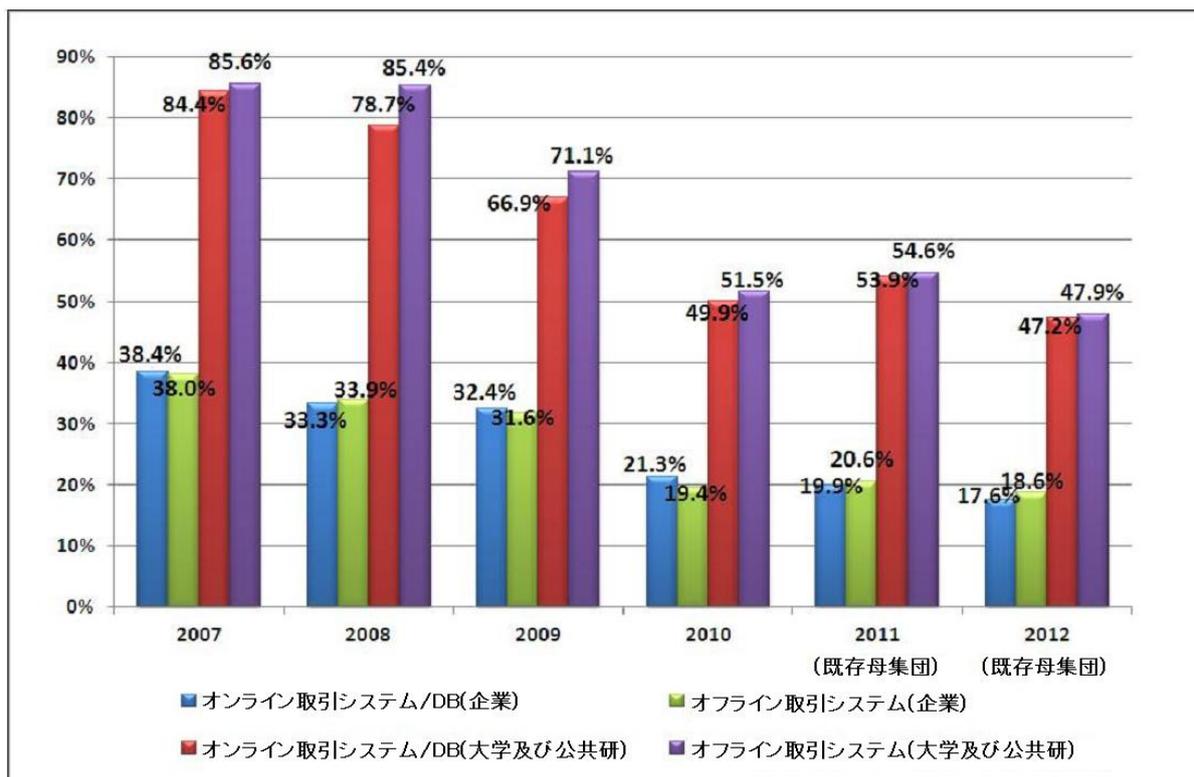
4.知的財産移転に向けた努力及び成果の減少

最近 3 年間技術取引、技術マーケティングのために大学・公共(研)TLO や民間技術取引機関などに業務を依頼したり、業務協約を締結した企業の比率推移は[図 4.10]のとおりである。図からも分かるように、各機関に業務を依頼または協約を締結した比率は 2011 年減少から 2012 年に増加している。特に、大学・公共(研)TLO、産学協力団に技術取引及び技術マーケティング関連の業務を依頼したり、業務協約を締結した比率が大幅上昇している。



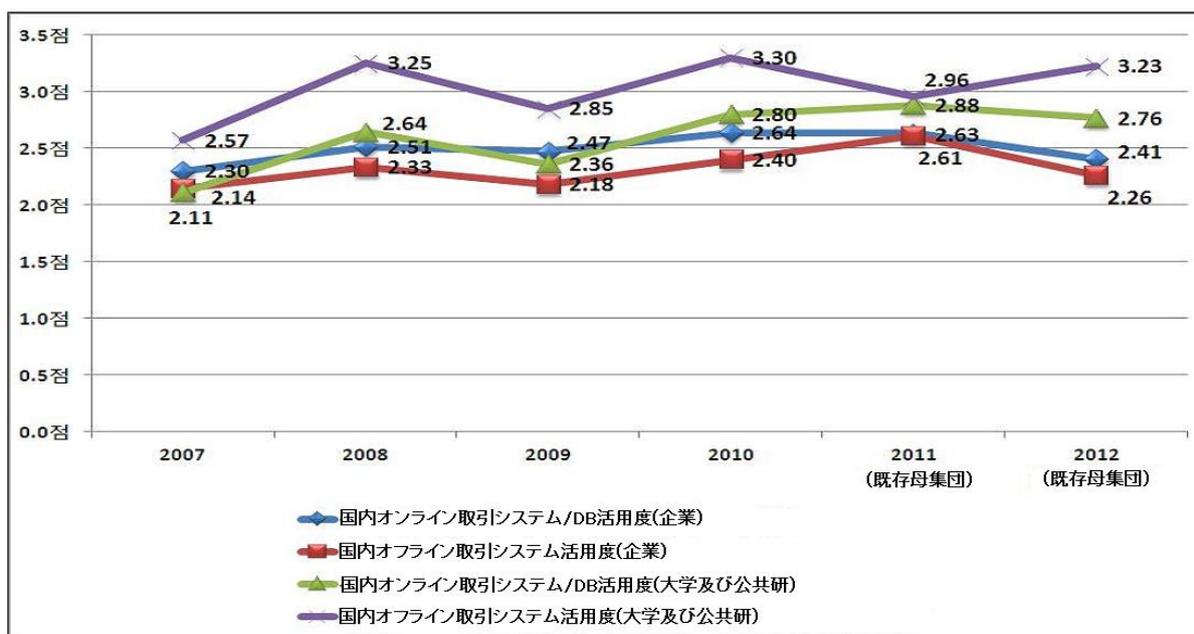
[図 4.10]最近 3 年間技術取引、技術マーケティングのための業務依頼の推移

技術取引及びマーケティングのために国内オンライン及びオフライン技術取引システムを活用している企業の比率は全般的に減少傾向にある([図 4.11]。国内オンライン及びオフライン技術取引システムを活用している大学及び公共(研)の比率は 2011 年に多少増加したが、2012 年に再び減少となっている。



[図 4.11]国内技術取引システム活用比率の推移

国内オンライン、オフライン技術取引システムを実際に活用している場合に企業及び公共機関が感じる活用度に関しては、オフラインシステムに対する公共機関の活用度を除けば全て 2011 年対比 2012 年には減少している([図 4.12])。



[図 4.12]国内技術取引システム活用度の推移

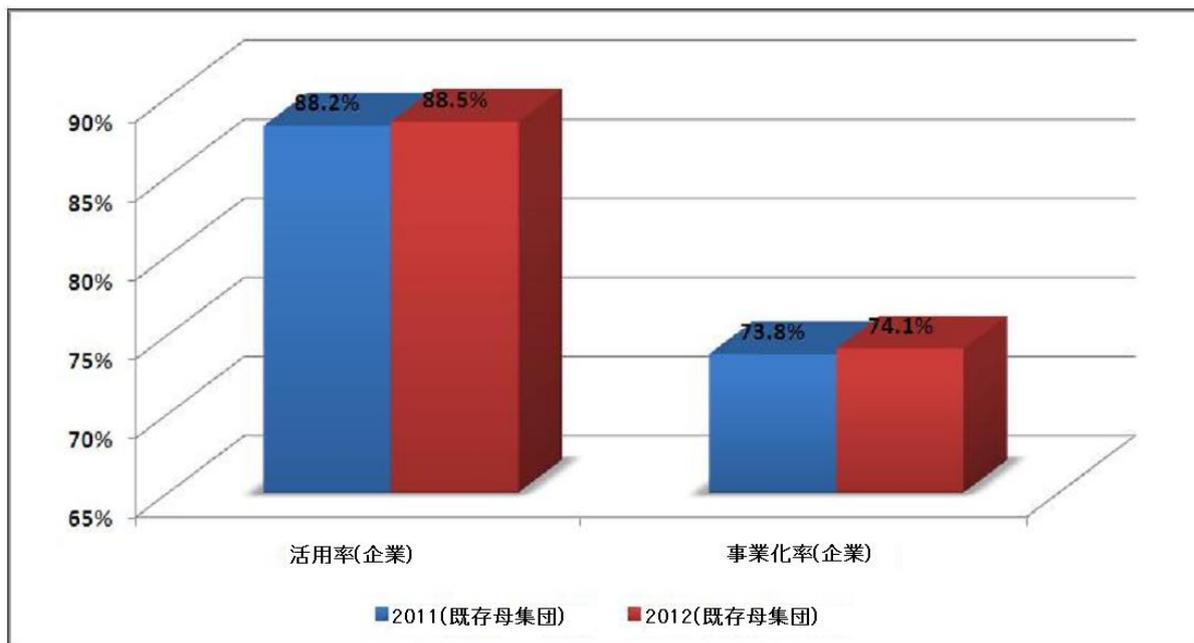
外部に知的財産を売却・移転した比率及び平均売却・移転件数の推移は[図 4.13]のとおりである。企業の場合 2011 年対比知的財産を売却・移転した比率は同水準を維持しているが、一方、知的財産を売却・移転した企業の平均件数は 2011 年 4.06 件から 2012 年 4.38 件に増加している。大学及び公共(研)の場合、知的財産を売却・移転した比率は 2011 年に比べて大きく増加している。一方、平均売却・移転件数は 2011 年 36.78 件から 2012 年 21.14 件に減少しているが、これは少ない件数ではあるものの売却に参加する機関数の増加で平均件数が低くなる結果をもたらしているものと見られる。言い換えると、企業の場合は知的財産を売却・移転する活動に参加する企業がその成果を高めることに集中する傾向にあり、大学及び公共(研)の場合は売却・移転活動に参加する機関が増えつつあるものの未だに初期参加者たちの成果が著しくないために相対的に実際売却・移転件の減少傾向にあると見られる。



[図 4.13]知的財産の売却・移転の推移

5.知的財産の活用及び事業化比率の増加

企業が保有している特許の平均活用率(事業化や防御の目的で保有する比率)と平均事業化率はいずれも 2011 年に比べて小幅増加となっている([図 4.14])。



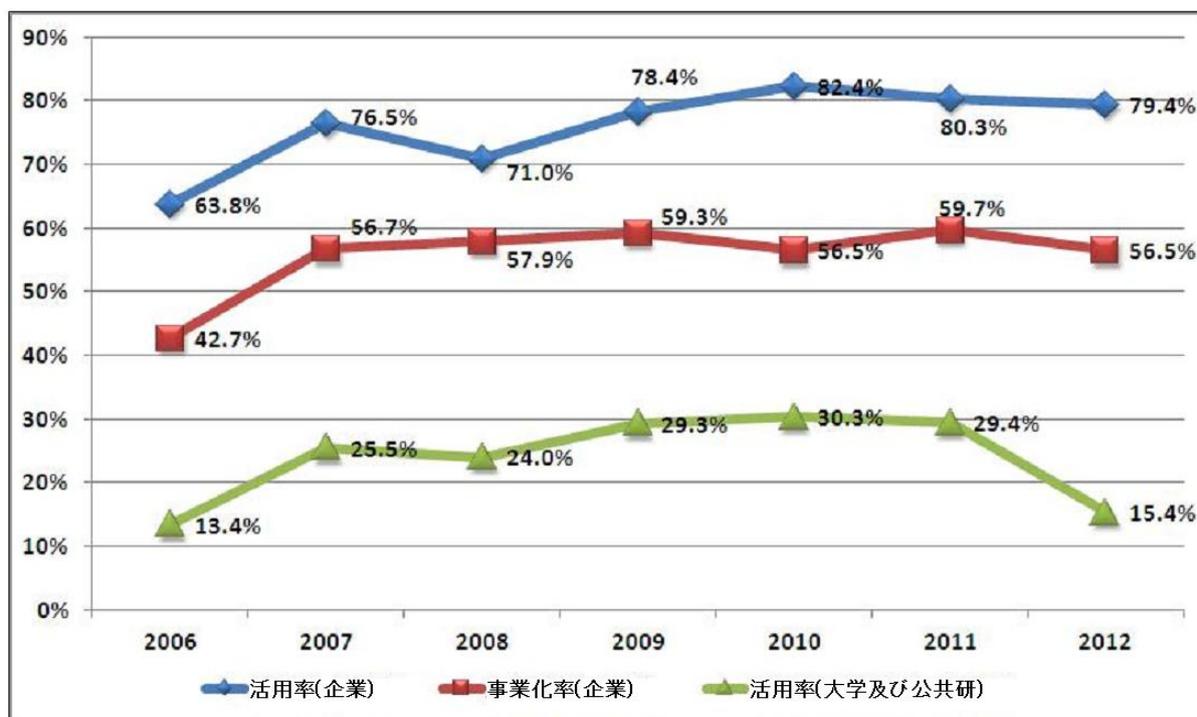
[図 4.14]特許活用率及び事業化率の平均

特に、企業の場合、知的財産の管理及び経営において技術開発は事業化を目的として戦略的に始めるため売却・移転に比べて事業化の可能性は高くなる可能性がある。しかし、一方の大学・公共(研)の場合、源泉技術の出願が事業化につながるまでの過程が極めて不確実な場合が多く、保護方法の確定が難しいため、通常の利用と関連して権利化された技術以外の技術移転が過小推定される可能性があるという点を考慮しなければならない。

各調査年度に回答した企業が保有している全ての特許を合算し、このうち活用されている比率と事業化されている比率は[図 4.15]のとおりである。⁷⁶個別企業の活用率、事業化率の平均値は昨年と比べて増加しているが、一方回答企業の全体保有件数対比活用件数及び事業化件数の比率は各々79.4%(82.6%)、56.5%(60.4%)となっており、多少減少している。これは多出願企業の活用率及び事業化率が加重反映されたために発生した結果であり、産業財産権の出願件数規模による企業の活用率を見ると、年平均10件未満の企業は87.3%、年平均10～20件の企業は84.0%、年平均21～60件の企業は82.3%、年平均61件以上の企業は76.3%と出願件数の多い企業ほど活用率が

⁷⁶ したがって多出願企業の活用率が加重反映されていると言える。

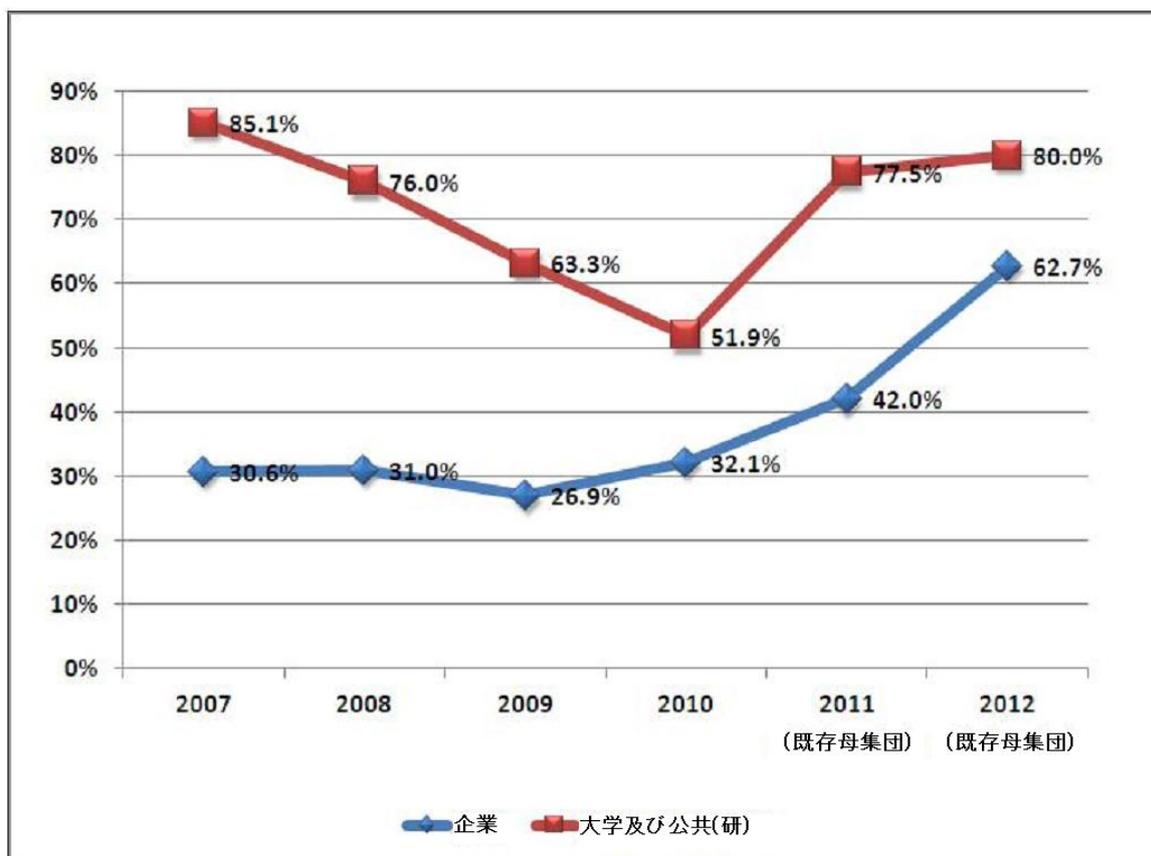
低いことがわかる。事業化率もまた年平均 10 件未満の企業は 71.4%、年平均 10～20 件の企業は 66.1%、年平均 21～60 件の企業は 58.2%、61 件以上の企業は 51.2%と出願規模が大きい企業ほど事業化率が低い。



[図 4.15]全体特許活用率及び事業化率

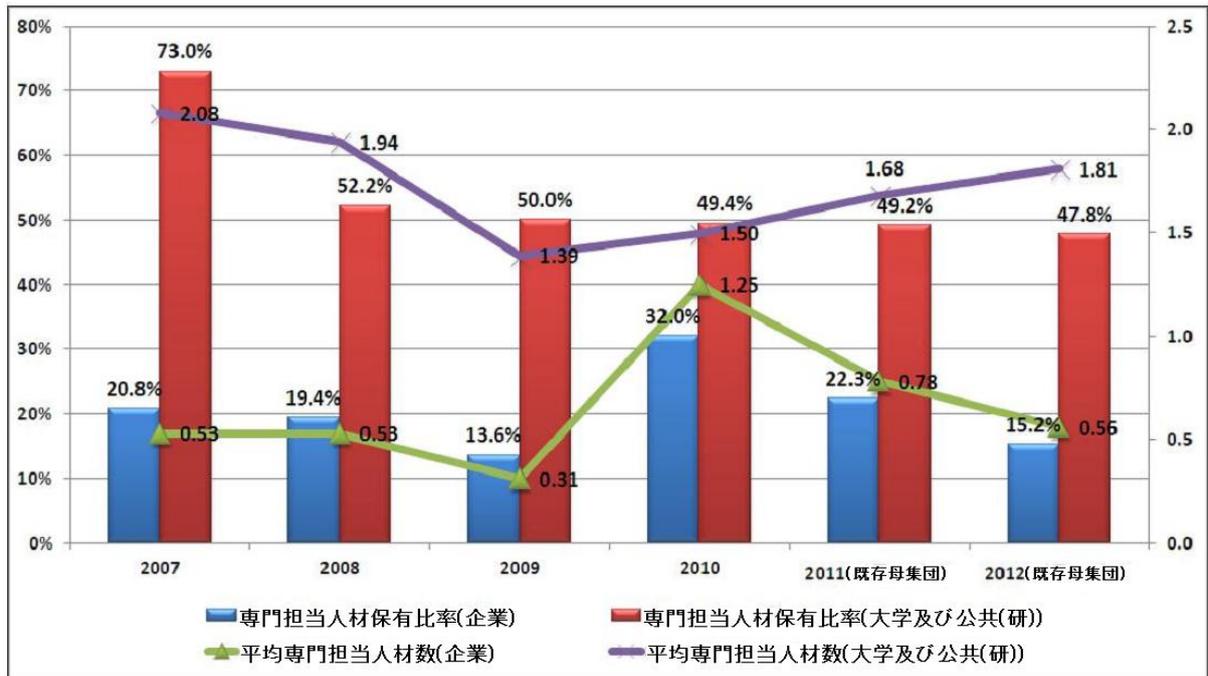
6.知的財産担当組織保有比率の改善

知的財産を担当する組織を保有している比率の推移は[図 4.16]のとおりである。企業の場合は知的財産担当組織の保有比率が 2009 年から着実に増加傾向にある。大学及び公共(研)の場合は 2010 年まで減少したが、2011 年調査では大きく増加し、2012 年度も小幅増加となっている。企業の場合、経営陣の知的財産管理に対する認識が知的財産担当組織の保有に影響を及ぼすことが多いが、最近知的財産の重要性に対する認識が高まるにつれ、知的財産を担当する組織及び管理が強化されていると見られる。これは 2011 年、2012 年重複回答企業分析の結果からも窺える。重複回答企業の担当組織保有比率は 2011 年 58.0%から 75.3%に増加しているが、このような増加は統計的に有意なものと分析されている(p<0.001)。



[図 4.16]知的財産担当組織保有比率の推移

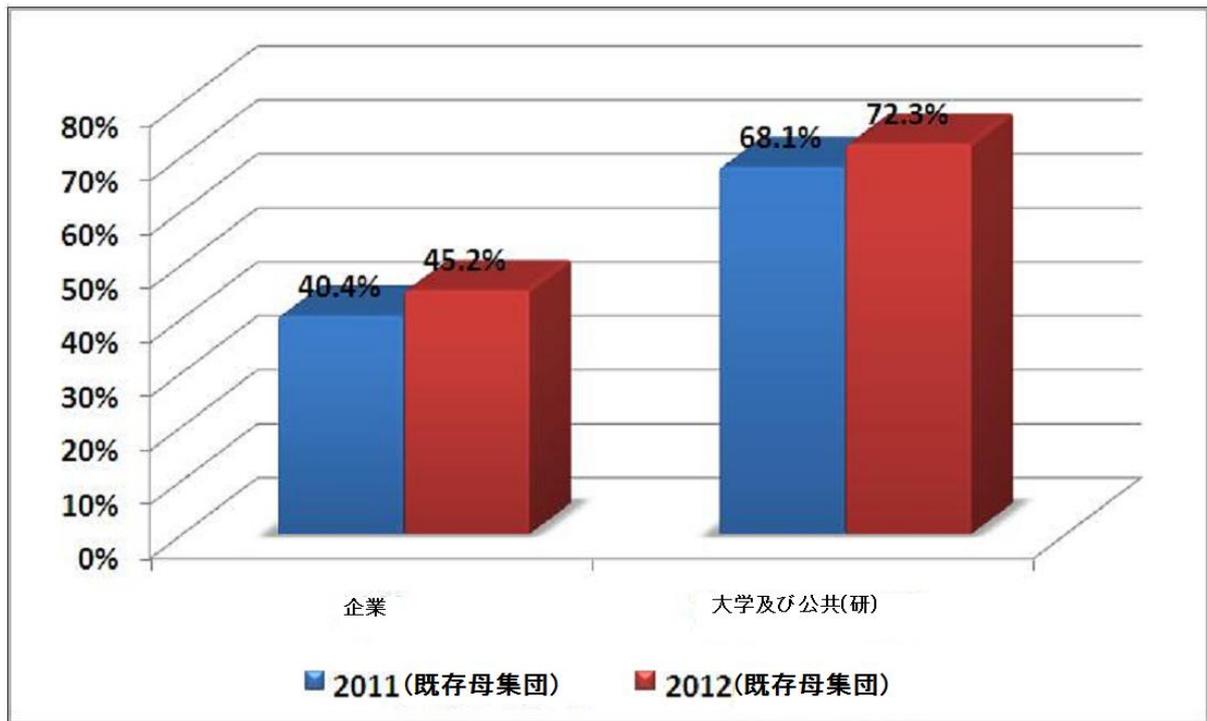
知的財産関連業務だけを専門的に行う専門担当人材を保有している企業及び大学・公共(研)の比率は 2011 年対比 2012 年に各々 22.3%、49.2%から 15.2%、47.8%に減少している。平均専門担当人材数もまた企業の場合 2011 年 0.78 名から 2012 年 0.56 名に減少しているが、大学及び公共(研)の場合は小幅増加となっている。一方、専門担当人材を保有している企業及び機関の平均専門担当人材数は 2011 年対比 2012 年に増加している。前述の知的財産専門担当組織の保有比率が増加していることと関連して知的財産の重要性に対する認識向上を通じて知的財産専門担当組織を備えている企業及び大学・公共(研)は人材の集中を通じて知的財産管理及び経営効率の最大化を図っているものと見られる。



[図 4.17] 専門担当人材の保有比率及び専門担当人材数の推移

知的財産担当人材を対象に職務教育を実施している比率は企業の場合 2011 年 40.4%から 2012 年 45.2%に増加し、大学及び公共(研)の場合 68.1%から 72.3%に増加している([図 4.18])。

希望する職務教育の内容として起業が特許紛争(訴訟)を挙げた比率が昨年 39.0%から 36.4%に減少し、大学及び公共(研)は特許情報分析方法、特許ライセンス、海外特許出願及び訴訟が各々 50.5%、71.9%、25.0%から 56.1%、73.7%、28.3%に増加している。すなわち、特許の紛争と活用と関連する専門性の向上を期待していると解釈できる。



[図 4.18]知的財産担当人材職務教育の実施状況

7.知的財産権侵害類型の特徴

知的財産侵害の特徴を見ると、まず侵害を受けた企業が全体の 4.3%(6.7%)となっている。これは 2011 年侵害を受けた企業が 6.6%(7.2%)であったことと比べると減少した数値である。侵害比率の減少と関連してみると、侵害を察知するためのモニタリング活動及び「探索費用」の減少を原因として把握できる。景気低迷が続く中で中小企業及びベンチャー企業の場合は特に「探索費用」を削減しており、その結果モニタリング活動が減少しているため侵害比率も減少していると思われる。本調査の「侵害製品の発見経路」の調査結果はこの事実を裏付けている。中小企業の場合「市場調査及びインターネットを通じた侵害の発見」が 2011 年に比べて減少しているが、「主に営業店を通じて侵害状況を確認」している点は侵害を探知するための「探索費用」を削減したことを意味する。

企業類型別では、侵害を受けた企業の比率は大企業が 5.3%(9.5%)、中小企業が 4.3%(6.9%)、ベンチャー企業が 4.1%(5.9%)となっている。特に特許権侵害を受けた企業の比率は 2.0%(3.3%)と他権利類型に比べて高く、侵害を受けた企業の平均侵害

件数は特許権が 2.82 件(2.22 件)と最も多く、デザインが 2.45 件(3.11 件)、商標が 2.44 件(2.55 件)、実用新案が 1.19 件(1.43 件)と続いている。

企業類型別では、特許権侵害を受けた大企業は 2.5%(3.5%)、一般中小企業は 1.4%(3.0%)、ベンチャー企業は 2.3%(3.4%)となっている。特許権の他に実用新案権とデザイン権の侵害を受けた比率が各々 0.4%(0.8%)と 2.1%(2.5%)と中小企業において最も高い。但し、商標権の場合は大企業が 2.4%(3.3%)と中小企業 0.5%(0.6%)よりその比率が高い。産業財産権の他に営業秘密侵害の被害を受けた企業は全体の 0.04%(0.2%)となっている。

一方、大企業、一般中小企業、ベンチャー企業はいずれも侵害事例のうち侵害製品の製造者が国内企業である比率が各々 76.8%(68.6%)、64.0%(86.7%)、75.6%(86.7%)と製造者が海外企業または個人である場合に比べて高くなっており、企業類型別では大きな差は見られない。

侵害製品の流通地域で見ると、全体被害事例のうち 85.6%(86.4%)は侵害製品の流通地域が国内となっている。また、流通地域が中国と米国である比重も各々 12.8%(10.0%)と 10.7%(9.1%)となっている。企業類型別では、流通地域が国内である比重は一般中小企業が 95.6%(100%)と他企業類型に比べて高く、大企業は 73.8%(65.7%)と最も低い。

侵害製品の流通類型がオンライン流通である場合は中小企業製品が 20.2%(26.7%)と他企業類型に比べて高く、オフライン流通は全体被害事例の 87.8%(82.7%)となっている。

用語整理

知的財産

人間の創造的な活動産物として産業財産権(特許、実用新案、商標、デザイン、サービス表)、著作権、新知的財産権(営業秘密、半導体配置設計など)、ノウハウなどを全て含む

知的財産権

産業、科学、文化、芸術分野の知的財産活動の結果として得られる法的権利として産業財産権の他に著作権、新知的財産権を総称

産業財産権

産業上の利用価値を持つ発明などに関する権利として、本調査の対象は特許権、実用新案権、デザイン権、商標権である

特許権

産業財産権の中で最も高度な技術性を持つもので、基本的に産業上の利用可能性、新規性、進歩性の3つの要件によって登録可能

実用新案権

既存の物品を改良して実用性と有用性を高めた考案を出願して付与される権利

デザイン権

産業的な物品または製品の独創的かつ装飾的な外見形状を保護するため、登録を通じて許容された権利を意味し、技術とは関係なく物品の美的外見を視覚的な観点から把握できるもの

商標権

生産者または商人が商標を特許庁に出願して登録することで登録商標を指定商標に独占的に使用できる権利

新知的財産権

経済・社会または文化の変化や科学技術の発展によって新しい分野で出現する知的財産(知識財産基本法第3条の2)で、伝統的な知的財産権の範疇では保護が難しいコンピュータプログラム、遺伝子組み換え動植物、半導体設計、インターネット、キャラクター産業などに関連する権利

著作権

著作権が自分の著作物を独占的に利用したり、それを他人に許諾できる人格的・財産的権利

職務発明

従業員(法人の役員を含む)がその職務に関して発明したものが性質上使用者・法人の業務範囲に属し、その発明をした行為が従業員の現在または過去の職務に属する発明(特許、実用新案、デザイン)

職務発明補償制度

従業員は職務発明に対して特許などを受けられる権利や特許権などを契約や勤務規定によって使用者・法人に承継させたり、専用実施権を設定した場合は正当な補償を受けられる権利を持つ制度(発明振興法)

職務発明補償規定

使用者・法人が承継した従業員の職務発明に対して正当な補償を定めた契約や勤務規定

出願補償

出願が完了した職務発明を対象に支給する補償

登録補償

登録された職務発明を対象に支給する補償

自社実施補償

職務発明を発明者が属している会社で利用して収益が発生した場合に支給する補償

他社実施補償

職務発明をライセンス契約などを通じて他企業に移転し、技術料収入が発生した場合に支給する補償

処分補償

職務発明を売却などを通じて処分して収入が発生した場合に支給する補償

先行特許(技術)調査

新技術開発などのための研究開発(R&D)活動に先立ち開発しようとする技術に対する先行技術または該当技術と同一もしくは類似する特許が存在するかどうかなどを調査

予備評価

提出された発明届出書に対して職務発明委員会などを通じて発明の評価、承継の可否、出願の可否、審査請求の可否などを決定すること

実査

特許などの維持/放棄の決定、事業化有望技術及び移転対象技術などを発掘するために保有している知的財産権の価値を把握すること

知的財産保護活動

保有している知的財産を権利化したり、社内機密及びノウハウとして維持するなど創出された知的財産を私有化するための活動

出願・審査費用

産業財産権の出願手数料、審査請求料、弁理士費用、決定系審判(特許出願に対する拒絶決定など審査官の処分不服して請求する審判)にかかった費用などを含めた金額

特許維持費用

産業財産権の登録と権利維持にかかる金額であり、登録料と維持年金を含めた金額

知的財産権の被侵害

知的財産権を侵害した製品・サービスが外部で製造・販売されることで該当知的財産権を保有する企業の利益に直間接的に被害を受けること

知的財産担当組織

知的財産戦略企画、国内外産業財産権の出願及び登録・維持管理、知的財産権の動向調査、特許侵害関連の対応及び訴訟業務、知的財産権の販売またはライセンス交渉及び技術料管理などの業務を担当する組織

知的財産サービス

知的財産の創出、管理、活用、保護、取引などを支援する専門サービスとして情報調査・分析、技術移転・取引、IP 翻訳、コンサルティングなどの事業

知的財産統計指標

知的財産統計年報などで提示する年度別出願件数及び登録件数、産業部門別の出願件数、国家別審判請求件数など、主に参考して活用する知的財産関連の統計指標

<付録1> 業種分類と韓国標準産業分類表(KSIC)との連結

<知的財産活動実態調査の業種分類>

知的財産活動実態調査の業種分類	韓国標準産業分類(9次改訂)
農林水産及び鉱業、 飲食料及びタバコ製造業	A.農業、林業及び漁業 B.鉱業 C10.食料品製造業 C11.飲料製造業 C12.タバコ製造業
卸及び小売業	G.卸及び小売業
事業サービス業、通信業	J61.通信業 J62.コンピュータプログラミング、システム統合及び管理業 J63.情報サービス業 M.専門、科学及び技術サービス業 N.事業施設管理及び事業支援サービス業
金融及び保険業	K.金融及び保険業
建設業	F.建設業
その他サービス業	D.電気、ガス、蒸気及び水道事業 E.下水・廃棄物処理、原料再生及び環境復元業 H.運輸業 I.宿泊及び飲食店業 J59.映像・オーディオ記録物の製作及び配給業 J60.放送業 L.不動産業及び賃貸業 O.公共行政、国防及び社会保障行政 P.教育サービス業 Q.保健業及び社会福祉サービス業 R.芸術、スポーツ及びレジャー関連サービス業 S.協会及び団体、修理及びその他個人サービス業

繊維製品、衣服、靴製造	C13.繊維製品製造業；衣服を除く C14.衣服、衣服アクセサリ及び毛皮製品製造業 C15.皮、靴及び靴製造業
紙及び印刷出版業	C17.パルプ、紙及び紙製品製造業 C18.印刷及び記録媒体複製業
化学産業	C19.コークス、練炭及び石油精製品製造業 C20.化学物質及び化学製品製造業；医薬品を除く C21.医療用物質及び医薬品製造業 C22.ゴム製品及びプラスチック製品製造業
鉄鋼及び金属産業	C23.非金属鉱物製品製造業 C24.1 次金属製造業
電気電子産業	C26.電子部品、コンピュータ、映像、音響及び通信装備製造業
機械産業	C25.金属加工製品製造業；機械及び家具を除く C27.医療、精密、光学機器及び時計製造業 C28.電気装備製造業 C29.その他機械及び装備製造業 C30.自動車及びトレーラー製造業 C31.その他運輸装備製造業
その他製造業	C16.木材及び木製品製造業；家具を除く C32.家具製造業 C33.その他製品製造業

<付録2> 調査票：企業用及び大学・公共(研)用



実施機関：特許庁

承認番号：第 13802 号

知的財産活動調査票

- 企業用 -

2012

特許庁

貿易委員会

韓国知識財産研究院

知的財産活動調査票(企業用)

ID

--	--	--	--

<調査概要>

本調査は韓国企業及び大学・公共(研)の知的財産活動状況を把握することで競争力強化に役立つ課題を発掘し、これを知的財産政策の樹立に反映することで企業及び大学・公共(研)の効果的な知的財産活動を支援するために特許庁、貿易委員会と韓国知識財産研究院が共同で行っております。

本調査は統計庁の承認統計として、この調査票に記載された内容は統計法第 33 条によって秘密が保護され、統計分析以外の他の目的では使用されません。本調査の要約結果は今後ご回答頂いた企業及び公共研究機関のご担当の方に e-mail で送付致します。本調査にご協力いただき、ありがとうございます。

<お問合せ>

韓国知識財産研究院(KIIP)電話番号：02-2189-2628

(株)コリアデータネットワーク(KDN)電話番号：02-548-5141

<送付方法>

調査票の送付手段はメール、FAX、郵便いずれも可能で、書類様式は韓国知識財産研究院のホームページ(<http://www.kiip.re.kr>)からダウンロードすることができます。

<送り先>

135-914 ソウル市江南区駅三洞 667-14KDN ビル キム・ヒョンイル課長、チョン・エリン代理

FAX：02-548-5144、02-512-0777

E-mail：bes0507@kdn21.co.kr

企業名		業種分類*	
		(下記の産業分類表を参照して <u>一つだけ</u>)	

		選択)	
企業(本社) 所在地		法人番号	
回答者名前		部署/職位	
回答者連絡先		回答者 E-mail	

*9 次標準産業分類(新分類)	
1. 農業、林業及び漁業 2. 鉱業 3. 電気、ガス、蒸気及び水道事業 4. 下水・廃棄物処理、原料再生及び環境復元業 5. 建設業 6. 卸及び小売業 7. 運輸業 8. 宿泊及び飲食店業 9. 出版、映像、放送通信及び情報サービス業 10. 金融及び保険業 11. 不動産及び賃貸業 12. 専門科学及び技術サービス業 13. 事業施設管理及び事業支援サービス業	21. パルプ及び紙製品製造業 22. 印刷及び記録媒体複製業 23. コークス、練炭及び石油精製品製造業 24. 化学物質及び化学製品製造業 25. 医療用物質及び医薬品製造業 26. ゴム及びプラスチック製品製造業 27. 非金属鉱物製品製造業 28. 第1次金属産業 29. 金属加工製品製造業 30. 電子部品、コンピュータ、映像、音響及び通信装備製造業 31. 医療、精密、光学機器及び時計製造業 32. 電気装備製造業 33. その他機械及び装備製造業 34. 自動車及びトレーラー製造業 35. その他運輸装備製造業 36. 家具製造業 37. その他製品製造業
14. 食料品製造業 15. 飲料製造業 16. タバコ製造業	

17. 繊維製品製造業 18. 衣服、衣服アクセサリ及び毛皮製品製造業 19. 皮、鞆及び靴製造業 20. 木材及び木製品製造業	38. その他 公共行政、国防、教育、保健、福祉、芸術、スポーツ、協会、個人サービス、自家消費生産に属する業種
---	--

I. 会社の一般事項及びインフラ

● 会社の形態及び規模

1. 企業類型による会社の形態(該当欄に✓チェック、2011年12月基準)

企業類型 1	企業類型 2	企業類型 3
・独立企業 ① ・国内グループ系列会社 ② ・海外グループ系列会社 ③	・大企業 ① ・一般中小企業 ② ・ベンチャー企業/ INNO-BIZ 企業 ③	・企業研究所(または R&D ① 専担部署)を保有 ・企業研究所を ② 保有していない

2. 従業員数、売上高、輸出額、R&D 人材及び費用(該当欄に数字で記入、2011年または会計年度基準)

従業員数 (臨時・日雇職を 除く)		名	総売上高	億ウォン
研究開発(R&D) 人材*	全体	男性	総輸出額 研究開発(R&D)費* *	億ウォン
		女性		億ウォン

※**研究開発人材**は研究所及び研究専門担当部署などに所属され、科学技術、産業技術などの研究開発活動に従事している人材と生産技術人材を意味し、機能職従事者、臨時職や管理職従事者は除く。「研究開発活動調査」に回答した場合は「科学技術研究開発活動調査票」の「研究開発人材」項目のうち「研究員数」を参照して研究開発人材数を記入。

※※**研究開発費**は新しい技術、製品を開発したり、既存の知識を活用して新しい方法を探し出すために行われた調査・研究活動に支出された費用として間接費は除く。「科学技術研究開発活動調査」に回答した場合は「科学技術研究開発活動調査票」の「研究開発費」項目を参照して記入。

知的財産*担当人材

※**知的財産**とは人間の創造的な活動の産物を総称する用語として、産業財産権(特許、実用新案など)、著作権、新知的財産権(営業秘密、半導体配置設計など)及び権利化されていないアイデア、ノウハウなどを全て含む。

※**産業財産権**とは産業上の利用価値を持つ発明などに関する権利として、特許権、実用新案権、デザイン権、商標権を含む。

※※**著作権**とは著作者が自分の著作物を独占的に利用したり、それを他人に許諾できる人格的、財産的権利を意味する。

※※※**新知的財産権**とは経済・社会または文化の変化や科学技術の発展によって新しい分野で出現する知的財産(知識財産基本法第 3 条の 2)で、伝統的な知的財産権の範疇では保護が難しいコンピュータプログラム、遺伝子組み換え動植物、半導体設計、インターネット、キャラクター産業などに関連する権利を意味する。

※**特許権**とは産業財産権の中で最も高度な技術性を持つもので、基本的に産業上の利用可能性、新規性、進歩性の 3 つの要件によって登録が可能。

※※**実用新案権**とは既存の物品を改良して実用性と有用性を高めた考案を出願して付与を受ける権利を意味する。

※※※**デザイン権**とは産業的的物品または製品の独創的かつ装飾的な外見形状を保護するために登録を通じて許容された権利を意味し、技術とは関係なく物品の美的外見を視覚的な観点から把握できるものを意味する。

※※※※**商標権**とは生産者または商人が商標を特許庁に出願して登録することで登録商標を指定商品に独占的に使用できる権利を意味する。

3. 知的財産担当組織※の存在(該当欄に✓チェック)

担当組織保有			担当組織なし
独立専門担当部署	法務組織/研究開発組織内	その他組織内	
①	②	③	④

4. 知的財産担当組織総括者の職位(1つだけ V 表示)

①社員 ②代理 ③課長 ④次長 ⑤部長 ⑥役員 ⑦その他()

5. 知的財産担当人材※の数(該当欄に数字で記入、いなければ 0 と表示)

知的財産専門担当人材※※	名	男性	名
		女性	名
その他部署業務(例：総務、人事、R&D 企画)との兼任人材	名	男性	名
		女性	名

※知的財産担当組織または人材は知的財産の戦略企画、国内外産業財産権の出願及び登録、維持管理、知的財産権の動向調査、特許侵害関連の対応及び訴訟業務、知的財産権の販売またはライセンス交渉及び技術料管理などの業務を担当する組織及び人材を意味する。

※※知的財産専門担当人材：知的財産関連業務だけを専門的に担当する人材

6. 知的財産担当者(兼任人材を含む)の主要業務(知的財産担当人材を 1 名以上保有する場合該当欄に✓チェック)

業務内容	人材数				
	ない	1~3 名 未満	3~5 名 未満	5~10 名 未満	10 名以上
産業財産権の出願/登録/維持	①	②	③	④	⑤

知的財産関連の紛争/訴訟	①	②	③	④	⑤
ライセンスなど知的財産の活用	①	②	③	④	⑤
知的財産の評価/分析/審査及び 知的財産戦略の樹立	①	②	③	④	⑤
知的財産関連の教育	①	②	③	④	⑤

7. 知的財産専門担当人材に対する今後の採用計画(該当欄に✓チェック)

現在保有していない場合		現在保有している場合	
新規採用計画がある	採用計画はない	追加採用計画がある	追加採用計画はない
①	②	③	④

知的財産担当人材の職務教育

8. 知的財産担当人材に対する職務教育の状況(該当欄に✓チェック)

職務教育を行っている		しない
機関が独自に実施	外部機関を通じて	
①	②	③

9. 知的財産担当人材向け職務教育の必要性(該当欄に✓チェック)

必要ない	←	普通	→	とても必要
①	②	③	④	⑤

10. 知的財産人材向け職務教育の実施を希望する場合、主に取り扱うべき教育内容(該当するものは全て✓チェック)

- ①特許制度 ②特許明細書の作成法 ③特許情報検索 ④特許紛争(訴訟)
 ⑤特許情報の分析法(特許マップ) ⑥特許ライセンス(技術事業化)
 ⑦海外特許出願及び訴訟 ⑧営業秘密保護 ⑨その他()

11. 知的財産人材の能力を高めるため政府が最も推進を急ぐべき課題(1 つだけ✓チェック)

- ①大学に特許関連教育課程及び学科の開設
 ②企業を対象とする実務中心教育課程の構成及び教材の開発

- ③企業の特許教育を担当する専門講師の育成
 ④新規知的財産人材の養成
 ⑤既存人材のための再教育プログラムの提供
 ⑥知的財産関連のコンサルティングまたは相談の提供
 ⑦その他()

12. 知的財産担当者に対する人件費及び教育費、知的財産関連の教育費

(該当欄に数字で記入、□2011年または□会計年度基準)

知的財産担当者に対する人件費※	(百万ウォン)
教育費(知的財産担当者対象)※※	(百万ウォン)
知的財産関連の教育費(研究開発者及び従業員対象)※※※	(百万ウォン)

※他業務と兼職である場合、知的財産関連業務の比重を考慮してお答えください。

※※知的財産担当者及び担当部署の知的財産専門能力を高めるために行われた対内外教育プログラムへの参加及び知的財産関連専門セミナーの進行など教育と関連する費用を意味する。

※※※知的財産の創出、権利化、活用などに関連して企業内部の研究開発者及び従業員の基礎的な知的財産関連素養を涵養するための教育費用を意味する。

 知的財産サービスの活用状況

※知的財産(IP)サービスとは知的財産の創出、保護、活用などを支援する専門サービスとして、情報調査・分析、技術移転・取引、翻訳、コンサルティングなどの事業

13. 国内知的財産サービスの活用状況及び分野別支出額(該当欄に✓チェック及び金額を記入)

現在の利用状況 (2011 基準、該当欄 に✓チェック)	分野	説明	支出額(2011年) (ない場合 0 記入)
利用している	① IP 情報調査/ 分析	特許 DB、調査分析、 特許マップの作成、動 向分析など	万ウォン
	技術移転/取引	技術マーケティング、 特許等級評価、技術評	万ウォン

		価など	
	IP 翻訳	明細書の翻訳、仕様書の翻訳、翻訳出版など	万ウォン
	IP コンサルティング/システム	IP 経営コンサルティング、IP 教育、IP システムの構築など	万ウォン
利用していない	利用していない理由(複数回答可能)		
	②	自社の保有人材で充分該当業務を行うことができる	
	③	必要性は認識しているもののどの機関を利用すればいいかわからない	
	④	知的財産サービスにかかる費用が高価である	
	⑤	知的財産サービス提供機関の品質が信頼できない	
	⑥	知的財産サービス提供機関の情報保安が信頼できない	
	⑦	その他()	

14. 知的財産サービス提供機関別の利用比重(該当欄に数値を記入)

区分	利用比重
民間知的財産サービス専門企業(弁理士事務所を除く)	%
弁理士事務所	%
韓国特許情報院、韓国発明振興会、技術保証基金など公共機関	%
合計	100%

II. 知的財産創出活動

先行特許調査*等特許情報の活用

*先行特許(技術)調査とは新技術開発などのための研究開発(R&D)活動に先立ち開発しようとする技術に対する先行技術または該当技術と同一もしくは類似する特許が存在するかどうかなどを調査することである。

15. 特許(技術)情報調査の現状及び必要性(該当欄に数字で記入及び✓チェック)

実施状況		必要性				
実施している	実施しない	必要ない ← 中間 → とても必要				
研究開発企画段階で全体研究開発課題のうち _____%	①	①	②	③	④	⑤

16. (先行特許調査を行っている場合)実施人材(該当するものは全て✓チェック)

内部人材			外部人材	
知的財産 専門担当人材	R&D 人材	その他(企画など)人材	弁理士/ 弁理士事務所	専門調査/ 評価機関
①	②	③	④	⑤

 知的財産基礎統計情報及び情報システムの活用

17. 知的財産統計など基礎統計情報の活用(該当欄に✓チェック及び直接記入)

①活用している(主に活用する統計指標※ : _____)

②活用していない

※知的財産統計年報などで提示する年度別出願件数及び登録件数、産業部門別出願件数、国家別審判請求件数など主に参考として活用する知的財産関連の統計指標を意味する。

18. より頻繁に公表してほしい統計指標 (_____)

19. 知的財産情報システムの活用度及び主に活用する情報システムの例示(該当欄に✓チェック及び直接記入)

	活用 しな い	活用度					(活用する場合) 主に活用する 情報システム
		低い	← 中間	→	高い		
KIPRIS など政府提供 の情報システム	①	①	②	③	④	⑤	()
WIPS、DELPION など 民間提供の情報システ	①	①	②	③	④	⑤	()

ム							
その他情報システム	①	②	③	④	⑤	()	

● 外部からの知的財産導入(outsourcing)*の方向と戦略

※外部から導入した知的財産は産業財産権(特許、実用新案、商標、デザイン)、著作権、新知的財産権(営業秘密、半導体配置設計など)、ノウハウなどを全て含む。

20. 外部からの知的財産導入方法による実績(該当欄に数字で記入)

□2011年または□会計年度基準	国内から	海外から
外部から導入した知的財産件数*	件 (このうち特許件数)	件 (このうち特許件数)
→ 実施許諾(licensing-in)を通じて導入	件	件
→ 購買/譲受を通じて導入	件	件
クロスライセンス、特許プール(patent pool)を通じて相互実施または共有形態で導入	件	件

※導入した回数ではなく、導入した産業財産権やノウハウの総件数でご記入ください。

21. 外部からの知的財産導入経路による実績(該当欄に✓チェック)

(1)~(7)の機関から最近3年間(2009~2011年)知的財産導入経験	ない	件数				
		1件	2~3件	4~5件	6~9件	10件以上
国内 (1)グループ系列会社	①	②	③	④	⑤	
(2)需要(納品)/供給(下請)企業	①	②	③	④	⑤	
(3)その他企業	①	②	③	④	⑤	
(4)大学	①	②	③	④	⑤	
(5) 出捐(研)など公共研究機関	①	②	③	④	⑤	

海外	(6)企業	①	②	③	④	⑤
	(7)大学及び研究所	①	②	③	④	⑤

22. 外部からの知的財産導入に向けた投資に対する今後の計画(該当欄に✓チェック)

①現在の水準より縮小 ②現在の水準を維持 ③現在の水準より拡大

23. (22 番質問事項の③を選択した場合)知的財産導入に向けた投資の拡大方向(該当するものは全て✓チェック)

国内		海外	
企業	大学及び研究機関	企業	大学及び研究機関
①	②	③	④

職務発明補償

※職務発明：従業員(法人の役員を含む)がその職務に関して発明したものが性質上使用者・法人の業務範囲に属し、その発明をした行為が従業員の現在または過去の職務に属する発明(特許、実用新案、デザイン)

※職務発明補償制度：従業員は職務発明に対して特許などを受けられる権利や特許権などを契約や勤務規定によって使用者・法人に承継させたり、専用実施権を設定した場合は正当な補償を受けられる権利を持つ制度(発明振興法)

24. 職務発明補償制度の認識度(該当欄に✓チェック)

区分	全く知らない ← → 非常に詳しい				
	①	②	③	④	⑤
(1)職務発明補償制度に対して	①	②	③	④	⑤
(2)職務発明と個人発明(職務発明以外の発明)の概念に対して	①	②	③	④	⑤
(3)職務発明に対する権利の帰属または承継に対して	①	②	③	④	⑤
(4)補償の算定方法(金銭的・非金銭的)に対して	①	②	③	④	⑤

25. 職務発明補償規定*の保有・活用状況(該当欄に✓チェック)

保有している(該当欄に✓チェック後 27 番へ移動)		保有していない (チェック後、26 番 へ移動)
企業独自に 職務発明補償規定を作成・活用	特許庁など関連機関が作成・ 普及した標準化された職務発 明補償規定を保有・活用	
①	②	③

※職務発明補償規定：使用者・法人が承継した従業員の職務発明に対して正当な補償を定めた契約や勤務規定

26. (職務発明補償規定を保有していない場合)その主な理由(該当欄に✓チェック、チェック後、30 番質問事項へ)

- ①職務発明補償金を支給する必要がない
- ②他職員との公平性
- ③補償規定がなくても別途のインセンティブが与えられる
- ④補償金を支給する場合、企業の負担が大きくなるため
- ⑤必要性は認識しているもののどのように導入すればいいかわからない
- ⑥使用者の導入意志が全くない

27. 職務発明補償の実施状況と補償金の水準(該当欄に✓チェック)

※出願補償：出願が完了した職務発明を対象に支給する補償
 ※※登録補償：登録された職務発明を対象に支給する補償
 ※※※自社実施補償：職務発明を発明者が属している会社で利用して収益が発生した場合に支給する補償
 ※※※※他社実施補償：職務発明をライセンス契約などを通じて他企業に移転し、技術料収入が発生した場合に支給する補償
 ※※※※※処分補償：職務発明を売却などを通じて処分して収入が発生した場合に支給する補償

区分	実施状況				金銭的補償を実施する場合、職務発明補償金の水準
	金銭的補	非金銭的補償(昇進、成	両方補償	実施しない	

	償	果評価反映)			
発明提案(発明届出)補償	①	②	③	④	_____ 万ウォン
出願留保補償	①	②	③	④	_____ 万ウォン
国内出願補償*	①	②	③	④	_____ 万ウォン
国内登録補償**	①	②	③	④	_____ 万ウォン
海外特許出願補償	①	②	③	④	_____ 万ウォン
海外特許登録補償	①	②	③	④	_____ 万ウォン
その他産業財産権の国内登録補償	①	②	③	④	_____ 万ウォン
その他産業財産権の海外登録補償	①	②	③	④	_____ 万ウォン
					一定比率支給の場合 固定金額支給の場合
自社実施補償***	①	②	③	④	収入金の平均 _____ % _____ 万ウォン
他社実施補償***	①	②	③	④	収入金の平均 _____ % _____ 万ウォン
処分補償****	①	②	③	④	収入金の平均 _____ % _____ 万ウォン

28. 支給された職務発明関連の補償費用※(□2011年または□会計年度基準、該当欄に数字で記入)

補償の種類	補償費用
(1)発明届出補償/出願/登録補償	(百万ウォン)
(2)実施/処分補償	(百万ウォン)

※職務発明補償費用は貴社が定めた補償制度に基づき発明者と創作者などに支払った補償金である(実施補償、処分補償など)

29. 職務発明補償と関連するあらゆる制度の効果(該当欄に V 表示)

(企業レベルや国家レベルで現在の実施状況とは関係なくお答えください。)

関連制度		効果ない ← →とても効果的				
		①	②	③	④	⑤
従業員の職務発明に対する補償実施または補償水準の拡大(企業→発明者)	発明の品質及び件数の増加	①	②	③	④	⑤
	技術流出の防止	①	②	③	④	⑤
職務発明補償制度の実施企業に対する税金の減免(政府→企業)	発明の品質及び件数の増加	①	②	③	④	⑤
	技術流出の防止	①	②	③	④	⑤
職務発明補償金に対する所得税の非課税(政府→発明者)	発明の品質及び件数の増加	①	②	③	④	⑤
	技術流出の防止	①	②	③	④	⑤

政府の政策支援及び必要性

30. 国内企業の効果的な知的財産創出に向けた政策支援の必要性

	政府政策の必要性				
	低い	←	中間	→	高い
(1)職務発明補償制度の実施企業に対する税制メリットの付与、関連規定の整備などを通じて企業が職務発明補償制度を導入したり、補償水準が拡大できるように支援	①	②	③	④	⑤
(2)特許情報活用拡散事業の拡大などを通じて深みのある先行特許調査と特許情報活用を支援	①	②	③	④	⑤
(3)中小企業特許コンサルティング事業の拡大などを通じて中小企業の知的財産権創出活動を支援	①	②	③	④	⑤
(4)多様な技術分野に対する特許マップ(patent map)の構築支援	①	②	③	④	⑤
(5)研究者などを対象とする知的財産権関連教育の支援(例：教育プログラムの開発及び普及、教育関連費用の支援など)	①	②	③	④	⑤

(6)その他()	①	②	③	④	⑤
-----------	---	---	---	---	---

Ⅲ. 知的財産保護活動

知的財産保護の方向と戦略

31. 産業財産権(特許権、実用新案権、デザイン権、商標権)の出願などに先立ち社内予備評価*の実施状況及び必要性(該当欄に数字で記入及び✓チェック)

実施状況		必要性				
している	しない	必要ない	← 中間	→	とても必要	
全体届出られた発明のうち _____ %	①	②	③	④	⑤	

*「予備評価」とは提出された発明届出書に対して職務発明委員会などを通じて発明の評価、承継の可否、出願の可否、審査請求の可否などを決定することを意味する。

32. (予備評価を実施している場合)遂行人材(該当するもの全てに✓チェック)

内部人材			外部人材	
知的財産専門 担当人材	R&D 人材	その他(審議委 員会など)人材	弁理士/ 弁理士事務所	専門調査/ 評価機関
①	②	③	④	⑤

33. (模倣業者などから)研究開発活動の成果を保護するために活用する戦略(該当欄に✓チェック)

	活用 しない	活用度				
		低い	← 中間	→	高い	
(1)特許など産業財産権の出願/登録	①	②	③	④	⑤	
(2)営業秘密及びノウハウとして維持	①	②	③	④	⑤	
(3)競合社より先に市場を先占	①	②	③	④	⑤	
(4)複雑な設計方法を採用	①	②	③	④	⑤	

34. 発明届出(Invention disclosure)件数対比特許など産業財産権の出願比率

□2011年または□会計年度基準	比率
発明届出(Invention disclosure)件数=100の場合、	100((1)+(2)+(3)+(4))%
(1)産業財産権の出願など公式的な権利保護手続きを進行	%
(2)(営業秘密として維持など)非公式的な権利保護手続きを進行	%
(3)(経済性、技術性不足などの理由で)出願を留保または放棄する	%
(4)その他：	%

知的財産の管理及び保護に関する認識度

35. 現在国内の知的財産保護水準^{*}に対する意見(該当欄に✓チェック)

大幅な 弱化が必要	漸進的な 弱化が必要	現在の水準が 適正	漸進的な 強化が必要	大幅な 強化が必要
①	②	③	④	⑤

※知的財産の保護水準は特許制度のように知的財産に権利を付与するシステムの効率性と知的財産権が他人によって侵害を受けた時に対抗できる行政的、司法的措置が如何に整えられているのかを意味する。

36. 産業財産権の海外出願/登録の実績(該当欄に数字で記入)

		特許権の 海外出願/登録	デザイン権の 海外出願/登録	商標権の 海外出願/登録
2011年 実績	(個別国家)出願件数 [*]	(件)	(件)	(件)
	→ 米国など北米地域	(件)	(件)	(件)
	日本などアジア地域	(件)	(件)	(件)
	ヨーロッパ(EU)	(件)	(件)	(件)
	その他の地域	(件)	(件)	(件)
2011年	PCT出願 ^{**}	(件)		
	登録件数 [*]	(件)	(件)	(件)

実績	→	米国など北米地域	(件)	(件)	(件)
		日本などアジア地域	(件)	(件)	(件)
		ヨーロッパ(EU)	(件)	(件)	(件)
		その他の地域	(件)	(件)	(件)

※同じ産業財産権を複数の国家に個別に出願または登録した場合にはこれを全て合算してご記入ください。例えば、A という特許を米国、日本、ドイツに出願した場合、出願件数は1ではなく3でご記入ください。

※※但し、PCT 出願の場合は出願書に記載されている指定国の数に関係なく、1件としてご記入ください。

産業財産権出願の今後の計画

37. 2012年産業財産権の予想国内出願件数(該当欄に数字で記入及び✓チェック)

		国内特許	国内実用新案	国内デザイン	国内商標
2012年	出願/予想出願件数	(件)	(件)	(件)	(件)
2013年 以後	縮小	①	①	①	①
	維持	②	②	②	②
	拡大	③	③	③	③

38. 貴社の産業財産権国内出願の増減に影響を及ぼす要因(該当欄に✓チェック)

主要産業財産権の国内出願の増減に影響を及ぼす要因		重要度				
		低い ← 中間 → 高い				
企業内部的な要因	①研究開発投資の増減による研究成果の変化	①	②	③	④	⑤
	②企業の事業戦略の変化(事業分野の多角化または事業構造調整など)	①	②	③	④	⑤
	③企業の産業財産権戦略の変化(量または品質中心の知的財産出願戦略、維持費用対比収益性戦略の変化など)	①	②	③	④	⑤
外部の環境的な要因	④市場及び技術競争環境の変化(市場の拡大または縮小、新技術または新市場の出現など)	①	②	③	④	⑤

⑤国内及び世界景気の変動(国内総生産の増減、物価及び為替の変化、世界金融危機など)	①	②	③	④	⑤
⑥産業財産権の出願環境の改善及び支援制度の強化(出願手数料の減免、手続きの簡素化、知財権創出支援制度など)	①	②	③	④	⑤

39. 出願・審査・維持費用(□2011年または□会計年度基準、弁理士費用を含む)

	国内出願	海外出願 (PCT出願を含む)
出願・審査費用※	(百万ウォン)	(百万ウォン)
→ 特許/実用新案権の出願・審査費用	%	%
維持費用**	(百万ウォン)	(百万ウォン)
→ 特許/実用新案権の維持費用	%	%

※出願・審査費用は産業財産権の出願手数料、審査請求料、弁理士費用、決定系審判(特許出願に対する拒絶決定など審査官の処分に不服して請求する審判)にかかった費用などを含めた金額である。

※※維持費用は産業財産権の登録と権利維持にかかる金額であり、登録料と維持年金を含めた金額である。

 営業秘密管理及び技術流出防止管理の状況

40. 営業秘密管理及び技術流出防止指針の保有及び遵守状況

- ① 営業秘密管理指針及び技術流出防止指針があり、これを遵守している。
- ② 営業秘密管理指針及び技術流出防止指針はあるが、これに対する認識度が低い
- ③ 関連指針がない

41. 営業秘密管理及び技術流出防止のための人材管理状況(該当欄に✓チェック)

	している	しない
(1)内部者に対する秘密保護誓約書の締結	①	②
(2)定期的な関連教育の実施	①	②

(3) 転職禁止約定などの競業禁止の義務付け	①	②
(4) 外部者(取引先)に対する保安誓約書の作成など保護義務の明確化	①	②

42. 営業秘密管理及び技術流出防止のための物的管理状況(該当欄に✓チェック)

	している	しない
(1) 外部者に対するアクセス管理	①	②
(2) アクセス権限付与など内部者に対するアクセス管理	①	②
(3) 文書レベル指定(秘密、対外秘など)	①	②
(4) 電子文書の管理(USB、外部メールの遮断など)	①	②
(5) 非電子文書の管理(印刷、搬出、廃棄など)	①	②

43. 国内企業の効果的な知的財産保護のための政策支援

	政府政策の必要性				
	低い	← 中間	→	高い	
(1) 産業財産権の出願と登録にかかる費用の減免	①	②	③	④	⑤
(2) 海外出願関連の情報を提供	①	②	③	④	⑤
(3) 知的財産権侵害に対する強力な処罰基準の制定	①	②	③	④	⑤
(4) 知的財産権侵害に対するコンサルティング支援と共同取締り	①	②	③	④	⑤
(5) その他()	①	②	③	④	⑤

IV. 知的財産活用活動

● 知的財産活用の方向と戦略

44. 保有している知的財産権*に対する実査***(評価)の実施状況及び必要性(該当欄に数字で記入及び✓チェック)

実施状況		必要性		
している	しない	必要ない	← 中間	→ とても必要

保有している全体知的財産のうち _____%	<input type="checkbox"/> ①	①	②	③	④	⑤
------------------------	----------------------------	---	---	---	---	---

※**知的財産権**とは産業財産権(特許、実用新案など)の他に著作権、新知的財産権(営業秘密、半導体配置設計など)を総称

※※**保有知的財産権に対する実査**とは特許などの維持/放棄の決定、事業化有望技術及び移転対象技術などを発掘するために保有している知的財産権の価値を把握することを意味する。

45. (実査を実施している場合)実施人材(該当する全てのものに✓チェック)

内部人材			外部人材	
知的財産 専門担当人材	R&D 人材	その他(知的財産実査 委員会など)人材	弁理士/弁理士 事務所	専門調査 /評価機関
①	②	③	④	⑤

 **技術取引機関、技術マーケティング会社との協力**

46. 最近 3 年間(2009~2011 年)技術取引、技術マーケティングのために大学・公共研究機関 TLO や民間技術取引機関などに業務を依頼したり、業務協約を締結しているかどうかに関して(該当欄に✓チェック)

	業務協約を 締結	業務を依頼	依頼しない
(1)大学・公共研究機関 TLO、産学協力団	①	②	③
(2)地域技術移転センター、技術取引所など 国内公共機関	①	②	③
(3)国内民間技術仲介、技術マーケティング 会社	①	②	③
(4)海外機関または民間会社	①	②	③

47. (技術取引機関などに業務を依頼した場合)主な費用支払い方法(該当欄に✓チェック)

①調査/マーケティング費用など活動費(前金)+成功報酬(定額)

業財産権で、事業化可能性や経済的な価値が著しく落ちるため他機関への移転が不可能と判断される産業財産権は除く。

53. 国内企業の効果的な知的財産活用のための政策支援

	政府政策の必要性				
	低い	← 中間	→	高い	
(1)新技術製品の販路支援及びマーケティング活動支援	①	②	③	④	⑤
(2)偽造品及び模倣品の取締り強化	①	②	③	④	⑤
(3)新技術事業化のための中小/ベンチャー創業支援	①	②	③	④	⑤
(4)特許技術取引、流通システムの改善	①	②	③	④	⑤
(5)優秀技術の輸出支援	①	②	③	④	⑤
(6)地域知的財産センターなどを通じた出願から事業化までの特許総合コンサルティング支援(one-stop service)	①	②	③	④	⑤
(7)その他()	①	②	③	④	⑤

V. 知的財産侵害及び紛争

● 知的財産権侵害の被害*規模及び内容

※**知的財産権侵害の被害**：貴社の知的財産権を侵害した製品・サービスが外部で製造・販売されることで該当知的財産を保有する貴社の利益に直間接的な被害を受けたことを意味する。

54. 知的財産権侵害製品からの類型別被害件数(2011年基準)(なければ「0」記入後 64番へ)

権利類型		侵害製品の販売/流通地域					
		国内	米国	中国	日本	ヨーロッパ	その他
産業 財産権	(1)特許	件	件	件	件	件	件
	(2)実用新案	件	件	件	件	件	件

	(3)商標	件	件	件	件	件	件
	(4)デザイン(意匠)	件	件	件	件	件	件
新知的 財産権	(5)半導体配置設計	件	件	件	件	件	件
	(6)地理的表示	件	件	件	件	件	件
	(7)営業秘密	件	件	件	件	件	件
	(8)その他	件	件	件	件	件	件

55. (被害件数が1件以上の場合)具体的な侵害内容及び発見経路(複数回答)

NO.	(1)権利類型(下記の例を参照)	(2)侵害製品の製造者(下記の例を参照)	(3)侵害製品の製造地域(下記の例を参照)	(4)侵害製品の流通地域(下記の例を参照)	(5)侵害製品の流通類型(下記の例を参照)	(6)侵害製品の発見経路(下記の例を参照)
例示	①特許権	②国内企業	①国内	①国内④日本	①オンライン流通	③市場調査を通じて
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

(3)中国	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件
(4)日本	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件
(5)ヨーロッパ	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件
(6)その他地域	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件

59. 他企業などから知的財産権権利侵害の警告を受ける、もしくは訴訟が提起された状況(2011年基準、ない場合は「ない」に記入)

相手企業の 対応 発生地域	警告書の受取		交渉を要求 (ライセンス、 補償など)		調整、仲裁を 図る(調整委員会 など)		司法的な救済 手続きを申請		な い
	国内 企業	海外 企業	国内 企業	海外 企業	国内 企業	海外 企業	国内 企業	海外 企業	
(1)国内	件	件	件	件	件	件	件	件	
(2)米国	件	件	件	件	件	件	件	件	
(3)中国	件	件	件	件	件	件	件	件	
(4)日本	件	件	件	件	件	件	件	件	
(5)ヨーロッパ	件	件	件	件	件	件	件	件	
(6)その他地域	件	件	件	件	件	件	件	件	

60. 知的財産権侵害による被害が発生した時、効果的に対応するために行う活動
(侵害類型別に該当する項目に優先順位によって1から3まで番号を記載)

		行政機関に 取締り及び 調査を要請	民・刑事訴訟な ど司法的な救済 手続きを申請	警告書の 送付など 独自処理	対応 しな い	該当 経験 なし
侵 害 類 型	(1)国内製造・国内販売など 国内流通段階の被害の時	順位	順位	順位	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(2)海外製造・国内輸入販売 による被害の時	順位	順位	順位	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(3)国内製造・海外輸出販売	順位	順位	順位	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

による被害の時					
(4)海外製造・海外輸出販売 による被害の時	順位	順位	順位	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※侵害類型(4)と回答した場合、行政機関及び司法的救済申請は該当地域(国家)の行政機関及び司法機関を利用した場合に該当する。

61. (行政機関への取締り及び調査要請の経験があると答えた場合)依頼した行政機関(複数回答可能)

①貿易委員会 ②特許庁 ③関税庁 ④警察庁 ⑤その他()

62. (対応活動を行わなかったと答えた場合)その理由

対応活動	対応しなかった理由
(1)行政機関に知的財産権侵害製品に対する取締り及び侵害事実に対する調査を要請	①申請手続きや活用方法が分からない ②人材と予算が不足 ③知的財産侵害への対応効果が少ない ④必要ない
(2)告訴・告発、仮処分、民・刑事訴訟など司法的救済手続きを申請	①申請手続きや活用方法が分からない ②人材と予算が不足 ③知的財産侵害への対応効果が少ない ④必要ない
(3)侵害企業に警告または合意を図るなど独自に対応	①独自の対応方法が分からず、対応しない ②人材と予算が不足 ③知的財産侵害への対応効果が少ない ④必要ない

63. 知的財産権侵害被害への対応費用(該当事項がない場合は「0」と記入)

被侵害への対応費用(紛争費用)	2011年	
知的財産権侵害被害への対応費用	件数	費用合計(百万ウォン)
☞ 警告書の送付から侵害訴訟完了時までかかった費用基準(損害賠償額または和解金額を除く)		

知的財産権紛争関連の難点及び必要な政府政策

64. 貴社の知財権が侵害された場合、対応する上で感じる難点

	難点の程度				
	低い	← 中間 →			高い
(1)言語及び地理的距離などの環境によって紛争相手との交渉が難しい	①	②	③	④	⑤
(2)該当国家における該当知財権法規など関連知識の習得が難しい	①	②	③	④	⑤
(3)該当国家には知財権保護のための行政的・司法的救済手続きが不備	①	②	③	④	⑤
(4)該当国家の行政府や司法府などの意志不足、または態度が非協力的	①	②	③	④	⑤
(5)対応時に過剰な時間と費用がかかる	①	②	③	④	⑤
(6)その他()	①	②	③	④	⑤

65. 他社の知財権を侵害することで紛争が発生した時、対応する上での難点

	難点の程度				
	低い	← 中間 →			高い
(1)法律代理人の選定が難しい	①	①	①	①	①
(2)内部人材の専門性不足	①	②	③	④	⑤
(3)対応関連の政府支援政策に対する情報不足	①	②	③	④	⑤
(4)該当企業及び国家の知財権関連事項に対する情報不足	①	②	③	④	⑤
(5)対応時に過剰な時間と費用がかかる	①	②	③	④	⑤
(6)その他()	①	②	③	④	⑤

66. 知的財産権侵害に対応するために必要な政府政策

	政府政策の必要性及び緊急度
--	---------------

	低い ← 中間 → 高い				
(1)実効性のある行政的・司法的処罰措置の強化	①	②	③	④	⑤
(2)迅速な権利救済のために国境措置対象の知的財産権範囲(特許、デザイン権)を拡大、侵害物品国内流入のシャットアウト	①	②	③	④	⑤
(3)知的財産権の保護及び対応活動のための情報提供活動の強化	①	②	③	④	⑤
(4)行政機関の知的財産権侵害製品の取締り権限の強化	①	②	③	④	⑤
(5)知的財産権侵害製品などに対する通報褒賞金額の増額	①	②	③	④	⑤
(6)知的財産権侵害対応のための訴訟などの費用支援	①	②	③	④	⑤
(7)その他()	①	②	③	④	⑤

アンケート調査に最後までご協力いただき、ありがとうございます。



実施機關:特許庁

承認番号:第 13802 号

知的財産活動調査票

- 大学、公共研究機関用 -

2012

特許庁
貿易委員会
韓国知識財産研究院

知的財産活動調査票(大学及び公共研究機関用)

ID

--	--	--	--	--

<調査概要>

本調査は韓国企業及び大学・公共(研)の知的財産活動状況を把握することで競争力強化に役立つ課題を発掘し、これを知的財産政策の樹立に反映することで企業及び大学・公共(研)の効果的な知的財産活動を支援するために特許庁、貿易委員会と韓国知識財産研究院が共同で行っております。

本調査は統計庁の承認統計として、この調査票に記載された内容は統計法第 33 条によって秘密が保護され、統計分析以外の他の目的では使用されません。本調査の要約結果は今後ご回答頂いた企業及び公共研究機関のご担当の方に e-mail で送付致します。本調査にご協力いただき、ありがとうございます。

<お問合せ>

韓国知識財産研究院(KIIP)電話番号：02-2189-2628

(株)コリアデータネットワーク(KDN)電話番号：02-548-5141

<送付方法>

調査票の送付手段はメール、FAX、郵便いずれも可能で、書類様式は韓国知識財産研究院のホームページ(<http://www.kiip.re.kr>)からダウンロードすることができます。

<送り先>

135-914 ソウル市江南区駅三洞 667-14KDN ビル キム・ヒョンイル課長、ジョン・エリン代理

FAX：02-548-5144、02-512-0777

E-mail：bes0507@kdn21.co.kr

機関名		機関所在地 (市/郡単位)	
-----	--	------------------	--

回答者名前		部署/職位	
回答者連絡先		回答者 E-mail	

I. 機関の一般事項及びインフラ

● 機関の研究開発規模

1. 研究開発人材※ (該当欄に数字で記入。2011年基準)

研究開発(R&D)人材		
全体	男性	女性
名	名	名

※ **研究開発人材**は学士号以上の学位所持者または同等以上の専門知識を備えている人で、科学技術、産業技術などの研究開発活動に従事している人材を意味し、機能職従事者、臨時職、管理職従事者は除く。

※ 「研究開発活動調査」に回答した場合は「科学技術研究開発活動調査票」の「研究開発人材」項目のうち「研究員数」を参照して研究開発人材数を記入。

2. 研究開発費※(該当欄に数字で記入。2011年基準)

研究開発(R&D)費(共通)	政府からの研究開発費	億ウォン
	企業からの研究開発費	億ウォン
	自己負担研究開発費	億ウォン

※ **研究開発費**は新しい技術、製品を開発したり、既存の知識を活用して新しい方法を探し出すために行われた調査・研究活動に支出された費用として間接費は除く。

「科学技術研究開発活動調査」に回答した場合は「科学技術研究開発活動調査票」の「研究開発費」項目を参照して記入。

● 知的財産※担当人材

※ **知的財産**とは人間の創造的な活動の産物を総称する用語として、産業財産権(特許、実用新案など)、著作権、新知的財産権(営業秘密、半導体配置設計など)及び権利化されていないアイデア、ノウハウなどを全て含む。

※ **産業財産権**とは産業上の利用価値を持つ発明などに関する権利として、特許権、

実用新案権、デザイン権、商標権を含む。

※※ 著作権とは著作者が自分の著作物を独占的に利用したり、これを他人に許諾できる人格的、財産的権利を意味する。

※※※ 新知的財産権とは経済・社会または文化の変化や科学技術の発展によって新しい分野で出現する知的財産(知識財産基本法第 3 条の 2)で、伝統的な知的財産権の範疇では保護が難しいコンピュータプログラム、遺伝子組み換え動植物、半導体設計、インターネット、キャラクター産業などに関連する権利を意味する。

※特許権とは産業財産権の中で最も高度な技術性を持つもので、基本的に産業上の利用可能性、新規性、進歩性の 3 つの要件によって登録が可能。

※※実用新案権とは既存の物品を改良して実用性と有用性を高めた考案を出願して付与を受ける権利を意味する。

※※※デザイン権とは産業的物品または製品の独創的かつ装飾的な外見形状を保護するために登録を通じて許容された権利を意味し、技術とは関係なく物品の美的外見を視覚的な観点から把握できるものを意味する。

※※※※商標権とは生産者または商人が商標を特許庁に出願して登録することで登録商標を指定商品に独占的に使用できる権利を意味する。

3. 知的財産担当組織[※]の存在(該当欄に✓チェック)

担当組織保有		担当組織なし
一般行政組織内	R&D 企画・管理組織や産学協力団内	
①	②	③

4. 知的財産担当者[※]の数(該当欄に数字で記入)

知的財産専門担当人材※※	名	男性	名
		女性	名
その他部署業務(例：総務、人事、R&D 企画)との兼任人材	名	男性	名
		女性	名

※知的財産担当組織または人材は知的財産の戦略企画、国内外産業財産権の出願及び登録、維持管理、知的財産権の動向調査、特許侵害関連の対応及び訴訟業務、知的財産権の販売またはライセンス交渉及び技術料管理などの業務を担当する組織及び人材を意味する。

※※知的財産専門担当人材：知的財産関連業務だけを専門的に担当する人材

5. 知的財産担当者(兼任人材を含む)の主要業務(知的財産担当人材を1名以上保有する場合該当欄に✓チェック)

業務内容	人材数				
	ない	1～3名 未満	3～5名 未満	5～10名 未満	10名以上
産業財産権の出願/登録/維持	①	②	③	④	⑤
知的財産関連の紛争/訴訟	①	②	③	④	⑤
ライセンスなど知的財産の活用	①	②	③	④	⑤
知的財産の評価/分析/審査及び知的財産戦略の樹立	①	②	③	④	⑤
知的財産関連の教育	①	②	③	④	⑤

6. 知的財産専門担当人材に対する今後の採用計画(該当欄に✓チェック)

現在保有していない場合		現在保有している場合	
新規採用計画がある	採用計画はない	追加採用計画がある	追加採用計画はない
①	②	③	④

知的財産担当人材の職務教育

7. 知的財産担当人材に対する職務教育の状況(該当欄に✓チェック)

職務教育を行っている		しない
機関が独自に実施	外部機関を通じて	
①	②	③

8. 知的財産担当人材向け職務教育の必要性(該当欄に✓チェック)

必要ない	←	普通	→	とても必要
①	②	③	④	⑤

9. 知的財産人材向け職務教育の実施を希望する場合、主に取り扱うべき教育内容(該当するものは全て✓チェック)

- ①特許制度 ②特許明細書の作成法 ③特許情報検索 ④特許紛争(訴訟)
 ⑤特許情報の分析法(特許マップ) ⑥特許ライセンス(技術事業化)
 ⑦海外特許出願及び訴訟 ⑧営業秘密保護 ⑨その他()

10. 知的財産人材の能力を高めるため政府が最も推進を急ぐべき課題(1 つだけ✓チェック)

- ①大学に特許関連教育課程及び学科の開設
 ②企業を対象とする実務中心教育課程の構成及び教材の開発
 ③企業の特許教育を担当する専門講師の育成 ④新規知的財産人材の養成
 ⑤既存人材のための再教育プログラムの提供
 ⑥知的財産関連のコンサルティングまたは相談の提供 ⑦その他()

11. 知的財産担当者に対する人件費及び教育費(2011年基準)

知的財産担当者に対する人件費※	(百万ウォン)
教育費(知的財産担当者対象)※※	(百万ウォン)
知的財産関連の教育費(研究開発者など従業員対象)※※※	(百万ウォン)

※他業務と兼職である場合、知的財産関連業務の比重を考慮してお答えください。

※※知的財産担当者及び担当部署の知的財産専門能力を高めるために行われた対内外教育プログラムへの参加及び知的財産関連専門セミナーの進行など教育と関連する費用を意味する。

※※※知的財産の創出、権利化、活用などに関連して企業内部の研究開発者及び従業員の基礎的な知的財産関連素養を涵養するための教育費用を意味する。

知的財産サービスの活用状況

※知的財産(IP)サービスとは知的財産の創出、保護、活用などを支援する専門サービス

スとして、情報調査・分析、技術移転・取引、翻訳、コンサルティングなどの事業

12. 国内知的財産サービスの活用状況及び分野別支出額(該当欄に✓チェック及び金額を記入)

現在の利用状況 (2011 基準、該当欄 に✓チェック)	分野	説明	支出額(2011 年) (ない場合 0 記入)	
利用している	①	IP 情報調査/ 分析	特許 DB、調査分析、 特許マップの作成、動 向分析など	万ウォン
		技術移転/ 取引	技術マーケティング、 特許等級評価、技術評 価など	万ウォン
		IP 翻訳	明細書の翻訳、仕様書 の翻訳、翻訳出版など	万ウォン
		IP コンサルティ ング/システム	IP 経営コンサルティン グ、IP 教育、IP システ ムの構築など	万ウォン
利用していない	利用していない理由(複数回答可能)			
	②	自社の保有人材で充分該当業務を行うことができる		
	③	必要性は認識しているもののどの機関を利用すればいいか分から ない		
	④	知的財産サービスにかかる費用が高価である		
	⑤	知的財産サービス提供機関の品質が信頼できない		
	⑥	知的財産サービス提供機関の情報保安が信頼できない		
	⑦	その他()		

13. 知的財産サービス提供機関別の利用比重(該当欄に数値を記入)

区分	利用比重
----	------

民間知的財産サービス専門企業(弁理士事務所を除く)	%
弁理士事務所	%
韓国特許情報院、韓国発明振興会、技術保証基金など公共機関	%
合計	100%

 **総合的な知的財産管理システム**

14. 総合的な知的財産管理システムの構築または活用状況(該当欄に✓チェック)

- ①特許など出願/登録過程と目録などが管理されている(発明届出から出願、中間事件、登録、維持、放棄などに関連する行政手続きと特許費用、関連情報などの管理システムを保有)
- ②特許などの出願/登録過程と目録などが業績評価など人事管理、研究課題管理システム、技術移転システムと連動して総合的に管理されている。
- ③知的財産管理システムが構築されていない(→③にチェックした場合 16 番へ)

15. (知的財産管理システムを構築または活用している場合)構築方法と所要費用(2011年基準)

構築方法	構築費用または賃借費用 (年間維持費用を含む)					
	500万	1000万	3000万	5000万	1億	1億
	ウォン 未満	ウォン 未満	ウォン 未満	ウォン 未満	ウォン 未満	ウォン 以上
①機関固有の管理システムを構築	①	②	③	④	⑤	⑥
②外部の管理システムを賃借して活用	①	②	③	④	⑤	⑥

 (大学の場合)知的財産関連教育の現状

16. 知的財産関連講座の開設状況及び講座数

- ①開設されている(講座数 _____ 講座)
- ②開設されていない

17. 知的財産関連講座講師における専任教員の存在有無

- ①専任教員として存在する
- ②専任教員として存在しない

II. 知的財産創出活動

先行特許調査※など特許情報の活用

※ 先行特許(技術)調査とは新技術開発などのための研究開発(R&D)活動に先立ち開発しようとする技術に対する先行技術または該当技術と同一もしくは類似する特許が存在するかどうかなどを調査することである。

18. 特許(技術)情報調査の現状及び必要性(該当欄に数字で記入及び✓チェック)

実施状況		必要性				
実施している	実施しない	必要ない	← 中間 →	とても必要		
研究開発企画段階で全体研究開発課題のうち _____%	①	①	②	③	④	⑤

19. 機関レベルの特許(技術)情報調査支援の状況(該当するものは全て✓チェック)

- ①機関の主要研究分野に対する各国の特許情報、技術動向などを調査して特許マップとして構築、研究者に提供
- ②(研究者の要請がある場合)開発しようとする技術の動向や類似する特許が存在するかどうかを調査、研究者に提供
- ③研究者に技術動向や先行特許(技術)調査のための費用を支援
- ④特別な支援は行っていない

20. (先行特許調査を行っている場合)実施人材(該当するものは全て✓チェック)

内部人材			外部人材	
知的財産 専門担当人材	R&D 人材	その他(企画など)人材	弁理士/ 弁理士事務所	専門調査/ 評価機関
①	②	③	④	⑤

知的財産統計など基礎統計情報の活用

21. 知的財産統計など基礎統計情報の活用(該当欄に✓チェック及び直接記入)

①活用している(主に活用する統計指標※ : _____)

②活用していない

※知的財産統計年報などで提示する年度別出願件数及び登録件数、産業部門別出願件数、国家別審判請求件数など主に参考として活用する知的財産関連の統計指標を意味する。

22. より頻繁に公表してほしい統計指標 (_____)

23. 知的財産情報システムの活用度(該当欄に✓チェック)

	活用 しな い	活用度					(活用する場合) 主に活用する 情報システム
		低い	←	中間	→	高い	
KIPRIS など政府提供の 情報システム	①	①	②	③	④	⑤	()
WIPS、DELPION など 民間提供の情報システ ム	①	①	②	③	④	⑤	()
その他情報システム	①	①	②	③	④	⑤	()

知的財産創出のための研究開発(R&D)活動及び今後の戦略

24. 優秀な知的財産を創出するため、現在機関レベルで行っている活動(該当するものは全て✓チェック)

①機関の特性に適した研究開発の発掘及び機関独自の研究開発の拡大

②産学研協力を通じた共同/委託研究開発の拡大

③研究開発の際に市場ニーズが反映できる制度的な体系の構築

④中大型、重要研究開発課題から優秀特許を創り出すための研究開発企画の強化

25. (現在の実施状況とは関係なく)優秀な知的財産を創り出すために必要であると考え
る活動や戦略(重要度によって2つ以内で✓チェック)

- ①機関の特性に適した研究開発の発掘及び機関独自の研究開発の拡大
- ②産学研協力を通じた共同/委託研究開発の拡大
- ③研究開発の際に市場ニーズが反映できる制度的な体系の構築
- ④中大型、重要研究開発課題から優秀特許を創り出すための研究開発企画の強化

 **職務発明補償**

※**職務発明**：従業員(法人の役員を含む)がその職務に関して発明したものが性質上使用者・法人の業務範囲に属し、その発明をした行為が従業員の現在または過去の職務に属する発明(特許、実用新案、デザイン)

※**職務発明補償制度**：従業員は職務発明に対して特許などを受けられる権利や特許権などを契約や勤務規定によって使用者・法人に承継させたり、専用実施権を設定した場合は正当な補償を受けられる権利を持つ制度(発明振興法)

26. 職務発明補償制度の認識度(該当欄に✓チェック)

区分	全く知らない ← → 非常に詳しい				
	①	②	③	④	⑤
(1)職務発明補償制度に対して	①	②	③	④	⑤
(2)職務発明と個人発明(職務発明以外の発明)の概念に対して	①	②	③	④	⑤
(3)職務発明に対する権利の帰属または承継に対して	①	②	③	④	⑤
(4)補償の算定方法(金銭的・非金銭的)に対して	①	②	③	④	⑤

27. 職務発明補償規定*の保有・活用状況(該当欄に✓チェック)

保有している(該当欄に✓チェック後 29 番へ移動)		保有していない (チェック後、28 番へ移動)
企業独自に 職務発明補償規定を作成・活用	特許庁など関連機関が作成・普及した標準化された職務発明補償規定を保有・活用	
①	②	③

※職務発明補償規定：使用者・法人が承継した従業員の職務発明に対して正当な補償を定めた契約や勤務規定

28. (職務発明補償規定を保有していない場合)その主な理由(該当欄に✓チェック、チェック後、33番質問事項へ)

- ①職務発明補償金を支給する必要がない
- ②他職員との公平性
- ③補償規定がなくても別途のインセンティブが与えられる
- ④補償金を支給する場合、企業の負担が大きくなるため
- ⑤必要性は認識しているもののどのように導入すればいいかわからない
- ⑥使用者の導入意志が全くない

29. 職務発明補償の実施状況と補償金の水準(該当欄に✓チェック)

※出願補償：出願が完了した職務発明を対象に支給する補償
 ※※登録補償：登録された職務発明を対象に支給する補償
 ※※※自社実施補償：職務発明を発明者が属している会社で利用して収益が発生した場合に支給する補償
 ※※※※他社実施補償：職務発明をライセンス契約などを通じて他企業に移転し、技術料収入が発生した場合に支給する補償
 ※※※※※処分補償：職務発明を売却などを通じて処分して収入が発生した場合に支給する補償

区分	実施状況				金銭的補償を実施する場合、職務発明補償金の水準
	金銭的補償	非金銭的補償(昇進、成果評価反映)	両方補償	実施しない	
発明提案(発明届出)補償	①	②	③	④	_____万ウォン
出願留保補償	①	②	③	④	_____万ウォン
国内出願補償※	①	②	③	④	_____万ウォン
国内登録補償※※	①	②	③	④	_____万ウォン
海外特許出願補償	①	②	③	④	_____万ウォン

海外特許登録補償	①	②	③	④	_____ 万ウォン	
その他産業財産権の 国内登録補償	①	②	③	④	_____ 万ウォン	
その他産業財産権の 海外登録補償	①	②	③	④	_____ 万ウォン	
					一定比率支給の場合	固定金額支給の場合
自社実施補償***	①	②	③	④	収入金の平均 _____ %	_____ 万ウォン
他社実施補償***	①	②	③	④	収入金の平均 _____ %	_____ 万ウォン
処分補償****	①	②	③	④	収入金の平均 _____ %	_____ 万ウォン

30. 職務発明に対する非金銭的な補償(業績評価など)(該当欄に✓チェック)

	業績評価などに反映していない	(SCI 級)論文提出の時、業績評価に反映 =100 とする場合				
		30 以下	50 以下	70 以下	100 以下	100 超過
特許など産業財産権の国内出願	①	①	②	③	④	⑤
特許など産業財産権の海外出願	①	①	②	③	④	⑤
特許など産業財産権の国内登録	①	①	②	③	④	⑤
特許など産業財産権の海外登録	①	①	②	③	④	⑤
産業財産権の移転や売却を通じた技術料収入の発生	①	①	②	③	④	⑤

31. 支給された職務発明関連の補償費用※(2011 年基準、該当欄に数字で記入)

補償の種類	補償費用
(1)発明届出補償/出願/登録補償	_____ (百万ウォン)
(2)実施/処分補償	_____ (百万ウォン)

※職務発明補償費用は貴社が定めた補償制度に基づき発明者と創作者などに支払った補償金である(実施補償、処分補償など)

32. 職務発明補償と関連するあらゆる制度の効果(該当欄に V 表示)

※企業レベルや国家レベルで現在の実施状況とは関係なくお答えください。

関連制度		効果ない ← →とても効果的				
		①	②	③	④	⑤
職務発明に対する補償実施または補償水準の拡大 (機関レベル)	発明の品質及び件数の増加	①	②	③	④	⑤
	技術流出の防止	①	②	③	④	⑤
職務発明補償金に対する 所得税の非課税 (政府レベル)	発明の品質及び件数の増加	①	②	③	④	⑤
	技術流出の防止	①	②	③	④	⑤

 政府の政策支援及び必要性

33. 国内大学及び公共研究機関の効果的な知的財産創出活動を支援するための政策支援

	政府政策の必要性				
	低い	←	中間	→	高い
(1)個別機関が <u>職務発明補償制度を導入したり、または補償水準が拡大できるように支援</u> (例:特許などの出願/登録による金銭的、非金銭的な補償に関する規定の整備及び広報など)	①	②	③	④	⑤
(2)特許情報活用拡散事業の拡大などを通じて深みのある <u>先行特許(技術)調査と特許情報の活用を支援</u>	①	②	③	④	⑤
(3) <u>専門家の派遣、知財権コンサルティング事業の拡大など</u> を通じて大学と公共研究機関の知的財産権創出活動を支援	①	②	③	④	⑤
(4)多様な技術分野に対する <u>特許マップの構築支援</u>	①	②	③	④	⑤

(5)研究者などを対象とした <u>知的財産権関連教育の支援</u> (例:教育プログラムの開発及び普及、教育関連費用の支援など)	①	②	③	④	⑤
---	---	---	---	---	---

Ⅲ. 知的財産保護活動

● 知的財産保護の方向と戦略

※「予備評価」とは提出された発明届出書に対して職務発明委員会などを通じて発明の評価、承継の可否、出願の可否、審査請求の可否などを決定することを意味する。

34. 産業財産権(特許権、実用新案権、デザイン権、商標権)の出願などに先立ち社内予備評価の実施状況及び必要性(該当欄に数字で記入及び✓チェック)

実施状況		必要性				
している	しない	必要ない ←	中間	→	とても必要	
全体届出られた発明のうち _____ %	①	①	②	③	④	⑤

35. (予備評価を実施している場合)遂行人材(該当するもの全てに✓チェック)

内部人材			外部人材	
知的財産専門 担当人材	R&D 人材	その他(審議委 員会など)人材	弁理士/ 弁理士事務所	専門調査/ 評価機関
①	②	③	④	⑤

36. 研究開発活動の成果を専有(模倣業者などからの保護または独占的な活用)するために活用する戦略(該当欄に✓チェック)

	活用 しない	活用度				
		低い	← 中間	→	高い	
(1)特許など産業財産権の出願/登録	①	②	③	④	⑤	
(2)営業秘密及びノウハウとして維持	①	②	③	④	⑤	
(3)(事業化しようとする)企業などと排	①	②	③	④	⑤	

他のな契約を締結						
----------	--	--	--	--	--	--

37. 発明届出(Invention disclosure)件数対比特許など産業財産権の出願比率 (2011 年基準)

発明届出(Invention disclosure)の件数	件
(経済性、技術性不足などの理由で)出願を留保または放棄する	件
(営業秘密として維持など)非公式的な権利保護手続きを進行	件
産業財産権の出願など公式的な権利保護手続きを進行	件

 知的財産の管理及び保護に関する認識度

38. 現在国内の知的財産保護水準※に対する意見(該当欄に✓チェック)

大幅な 弱化が必要	漸進的な 弱化が必要	現在の水準が 適正	漸進的な 強化が必要	大幅な 強化が必要
①	②	③	④	⑤

※知的財産の保護水準は特許制度のように知的財産に権利を付与するシステムの効率性と知的財産権が他人によって侵害を受けた時に対抗できる行政的、司法的措置が如何に整えられているのかを意味する。

39. 産業財産権の海外出願/登録の実績(該当欄に数字で記入)

※同じ産業財産権を複数の国家に個別的に出願または登録した場合にはこれを全て合算してご記入ください。例えば、A という特許を米国、日本、ドイツに出願した場合、出願件数は1ではなく3でご記入ください。

※※但し、PCT 出願の場合は出願書に記載されている指定国の数に関係なく、1件としてご記入ください。

	特許権の 海外出願/登録	デザイン権の 海外出願/登録	商標権の 海外出願/登録
--	-----------------	-------------------	-----------------

2011年 実績	→	(個別国家)出願件数*	(件)	(件)	(件)
		米国など北米地域	(件)	(件)	(件)
		日本などアジア地域	(件)	(件)	(件)
		ヨーロッパ(EU)	(件)	(件)	(件)
		その他の地域	(件)	(件)	(件)
		PCT 出願**	(件)		
2011年 実績	→	登録件数*	(件)	(件)	(件)
		米国など北米地域	(件)	(件)	(件)
		日本などアジア地域	(件)	(件)	(件)
		ヨーロッパ(EU)	(件)	(件)	(件)
		その他の地域	(件)	(件)	(件)

産業財産権出願の今後の計画

40. 2012年産業財産権の予想国内出願件数(該当欄に数字で記入及び✓チェック)

		国内特許	国内実用新案	国内デザイン	国内商標
2012年	出願/予想出願件数	(件)	(件)	(件)	(件)
	縮小	①	①	①	①
2013年以後	維持	②	②	②	②
	拡大	③	③	③	③

41. 産業財産権の国内出願の増減に影響を及ぼす要因(該当欄に✓チェック)

主要産業財産権の国内出願の増減に影響を及ぼす要因		重要度				
		低い ← 中間 → 高い				
機 関 内 部 的 な 要 因	①研究開発投資の増減による研究成果の変化	①	②	③	④	⑤
	②機関の産業財産権戦略の変化(量または品質中心の知的財産出願戦略、維持費用対比収益性戦略の変化など)	①	②	③	④	⑤

	③産業財産権に対する成果評価比重の変化または評価方向の変化(論文などその他成果対比産業財産権実績評価比重の拡大または縮小、量的成果評価の止揚及び質的成果評価の指向など)	①	②	③	④	⑤
外部環境的な要因	④市場及び技術競争環境の変化(市場の拡大または縮小、新技術または新市場の出現など)	①	②	③	④	⑤
	⑤国内及び世界景気の変動(国内総生産の増減、物価及び為替の変化、世界金融危機など)	①	②	③	④	⑤
	⑥産業財産権の出願環境の改善及び支援制度の強化(出願手数料の減免、手続きの簡素化、知財権創出支援制度など)	①	②	③	④	⑤

42. 出願・審査・維持費用(□2011年または□会計年度基準)

		国内出願	海外出願 (PCT出願を含む)
出願・審査費用*		(百万ウォン)	(百万ウォン)
→	特許/実用新案権の出願・審査費用	%	%
維持費用**		(百万ウォン)	(百万ウォン)
→	特許/実用新案権の維持費用	%	%

※出願・審査費用は産業財産権の出願手数料、審査請求料、弁理士費用、決定系審判(特許出願に対する拒絶決定など審査官の処分に不服して請求する審判)にかかった費用などを含めた金額である。

※※維持費用は産業財産権の登録と権利維持にかかる金額であり、登録料と維持年金を含めた金額である。

43. 国内大学及び公共研究機関の効果的な知的財産管理及び保護を支援するための政策支援

	政府政策の必要性 低い ← 中間 → 高い
--	--------------------------

(1)産業財産権の出願と登録にかかる費用の減免	①	②	③	④	⑤
(2)海外出願関連の情報を提供	①	②	③	④	⑤
(3)企業などとの共同/委託研究契約の際、(発明所有権、実施権許与に対する決定権利、技術事業化の収益配分における)不平等契約を防止するためガイドラインの制定/広報	①	②	③	④	⑤
(4)出願前または出願後に知的財産の評価費用を支援	①	②	③	④	⑤
(5)その他()	①	②	③	④	⑤

IV. 知的財産活用活動

知的財産活用の方向と戦略

※**知的財産権**とは産業財産権(特許、実用新案など)の他に著作権、新知的財産権(営業秘密、半導体配置設計など)を総称

※※**保有知的財産権に対する実査**とは特許などの維持/放棄の決定、事業化有望技術及び移転対象技術などを発掘するために保有している知的財産権の価値を把握することを意味する。

44. 保有している知的財産権に対する実査(評価)の実施状況及び必要性(該当欄に数字で記入及び✓チェック)

実施状況		必要性				
している	しない	必要ない ←	中間	→	とても必要	
保有している全体知的財産権のうち _____%	<input type="checkbox"/> ①	①	②	③	④	⑤

45. (実査を実施している場合)実施人材(該当する全てのものに✓チェック)

内部人材			外部人材	
知的財産 専門担当人材	R&D 人 材	その他(知的財産実査 委員会など)人材	弁理士/ 弁理士事務所	専門調査 /評価機関

①	②	③	④	⑤
---	---	---	---	---

 **技術取引機関、技術マーケティング会社との協力**

46. 最近 3 年間技術取引、技術マーケティングのために国内外企業、技術取引機関などに業務を依頼したり、業務協約を締結しているかどうかに関して(該当欄に✓チェック)

	業務協約を 締結	業務を依頼	依頼しない
(1)大学・公共研究機関 TLO、産学協力団	①	②	③
(2)地域技術移転センター、技術取引所など国内公共機関	①	②	③
(3)国内民間技術仲介、技術マーケティング会社	①	②	③
(4)海外機関または民間会社	①	②	③

47. (技術取引機関などに業務を依頼した場合)主な費用支払い方法(該当欄に✓チェック)

- ①調査/マーケティング費用など活動費(前金)+成功報酬(定額)
- ②調査/マーケティング費用など活動費(前金)+成功報酬(技術移転収益などによる定率)
- ③成功報酬(定額) ④成功報酬(技術移転収益などによる定率) ⑤その他

48. 技術取引システムの活用度(該当欄に✓チェック)

	活用し ない	活用度				
		低い	← 中間 →	高い		
(1)IP-mart(インターネット特許技術広場)、NTB など国内オンライン取引システム/DB	①	①	②	③	④	⑤
(2)特許技術移転説明会など国内オフライン取引システム	①	①	②	③	④	⑤

(3)yet2.com など海外オンライン取引システム/DB	①	②	③	④	⑤
(4)海外オフライン取引システム	①	②	③	④	⑤

 知的財産*の売却または移転状況

※知的財産は産業財産権(特許、実用新案、商標、デザイン、サービス表)、著作権、新知的財産権(営業秘密、半導体配置設計など)、ノウハウなどを全て含む

49. 知的財産の売却または移転実績(該当欄に数字で記入、2011年基準)

		国内に売却または移転	海外に売却または移転
企業などに売却または移転した知的財産の件数		件 (このうち特許は 件)	件 (このうち特許は 件)
→	(共同または委託研究開発契約など)研究開発契約に <u>技術移転義務条項(強制実施)</u> が含まれ、移転または売却された知的財産の件数	件 (このうち特許は 件)	件 (このうち特許は 件)
	権利行使に <u>制約のない</u> 移転(licensing-out)件数	件 (このうち特許は 件)	件 (このうち特許は 件)
	独自の保有知的財産の売却(sale)件数	件 (このうち特許は 件)	件 (このうち特許は 件)

50. 知的財産の売却または移転の際、最も大きな難点(該当欄に✓チェック)

- ①取引機関の能力不足
- ②需要先-供給先の発掘が難しい
- ③技術料の算定が難しい(信頼できる評価機関の不足)
- ④保安上の問題で取引の推進が難しい
- ⑤その他()

51. 知的財産の有償実施許与または売買契約の成果(該当欄に数字で記入。2011年基準)

収入	
産業財産権の実施許与/売却	(百万ウォン)

			ノウハウのみの実施許与/売却	(百万ウォン)
→	国内	企業から		%
		その他法人から		%
→	海外	企業から		%
		その他法人から		%

52. 保有している登録産業財産権の活用状況(回答時点を基準に該当欄に数字で記入)

	特許権*	実用新案権	デザイン権*	商標権*
権利保有件数** (A+B)	件	件	件	件
活用件数(A)	件	件	件	件
→ 外部の他機関に移転	件	件	件	件
→ 実験室創業、研究員 創業などに活用	件	件	件	件
未活用件数(B)	(登録5年未満) 件	(登録5年未満) 件	未活用の主な理由：	
他機関に移転可能*	件	件		
**	(登録5年未満) 件	(登録5年未満) 件		
→	件	件		

※特許権、デザイン権、商標権は「登録された」特許権、デザイン権、商標権を対象とする。

※※現在(回答時点)を基準に登録され(取消、無効、放棄などで権利が消滅されず)権利が生きている総件数を記入する。

※※※他機関に移転可能：ライセンス契約などを通じて移転することに問題がない産業財産権で、事業化可能性や経済的な価値が著しく落ちるため他機関への移転が不可能と判断される産業財産権は除く。

53. 企業などに移転されたり、実験室創業、研究員創業などに活用している産業財産権のうち、これを通じて売上(技術料収入)が発生した権利の比率(回答時点を基準に該当欄に数字で記入)

	特許権	実用新案権	デザイン権	商標権
外部の他機関に移転または実験室創業、研究員創業などに活用されている権利の数(3.4 項目の活用件数(A)と同一)	件	件	件	件
→ 売上(技術料収入)が発生した権利の数	件	件	件	件

54. 国内大学及び公共研究機関の効果的な知的財産活用のための政策支援

	政府政策の必要性				
	低い	← 中間 →			高い
(1)保有特許技術に対する価値評価の支援	①	②	③	④	⑤
(2)新技術の事業化に向けた研究所企業/実験室創業の支援	①	②	③	④	⑤
(3)特許技術の取引、流通システムの改善	①	②	③	④	⑤
(4)技術移転関連のマーケティング及びコンサルティング支援	①	②	③	④	⑤
(5)優秀技術の輸出支援	①	②	③	④	⑤
(6)その他()	①	②	③	④	⑤

V. 知的財産侵害及び紛争

知的財産権侵害の被害*規模及び内容

※**知的財産権侵害の被害**：貴社の知的財産権を侵害した製品・サービスが外部で製造・販売されることで該当知的財産を保有する貴社の利益に直間接的な被害を受けたことを意味する。

55. 知的財産権侵害製品からの類型別被害件数(2011 年基準)(なければ「0」記入後 64 番へ)

権利類型		侵害製品の販売/流通地域					
		国内	米国	中国	日本	ヨーロッパ	その他
産業 財産権	(1)特許	件	件	件	件	件	件
	(2)実用新案	件	件	件	件	件	件
	(3)商標	件	件	件	件	件	件
	(4)デザイン(意匠)	件	件	件	件	件	件
新知的 財産権	(5)半導体配置設計	件	件	件	件	件	件
	(6)地理的表示	件	件	件	件	件	件
	(7)営業秘密	件	件	件	件	件	件
	(8)その他	件	件	件	件	件	件

56. (被害件数が1件以上の場合)具体的な侵害内容及び発見経路(複数回答)

NO.	(1)権利類型(下記の例を参照)	(2)侵害製品の製造者(下記の例を参照)	(3)侵害製品の製造地域(下記の例を参照)	(4)侵害製品の流通地域(下記の例を参照)	(5)侵害製品の流通類型(下記の例を参照)	(6)侵害製品の発見経路(下記の例を参照)
例示	①特許権	②国内企業	①国内	①国内④日本	①オンライン流通	③市場調査を通じて
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

60. 他企業などから知的財産権権利侵害の警告を受ける、もしくは訴訟が提起された状況(2011年基準、ない場合は「ない」に記入)

相手企業の 対応 発生地域	警告書の受取		交渉を要求 (ライセンス、 補償など)		調整、仲裁を 図る(調整委員会 など)		司法的な救済 手続きを申請		ない
	国内 企業	海外 企業	国内 企業	海外 企業	国内 企業	海外 企業	国内 企業	海外 企業	
(1)国内	件	件	件	件	件	件	件	件	
(2)米国	件	件	件	件	件	件	件	件	
(3)中国	件	件	件	件	件	件	件	件	
(4)日本	件	件	件	件	件	件	件	件	
(5)ヨーロッパ	件	件	件	件	件	件	件	件	
(6)その他地域	件	件	件	件	件	件	件	件	

61. (行政機関への取締り及び調査要請の経験があると答えた場合)依頼した行政機関(複数回答可能)

①貿易委員会 ②特許庁 ③関税庁 ④警察庁 ⑤その他()

62. (対応活動を行わなかったと答えた場合)その理由

対応活動	対応しなかった理由
(1)行政機関に知的財産権侵害製品に対する取締り及び侵害事実に対する調査を要請	①申請手続きや活用方法が分からない ②人材と予算が不足 ③知的財産侵害への対応効果が少ない ④必要ない
(2)告訴・告発、仮処分、民・刑事訴訟など司法的救済手続きを申請	①申請手続きや活用方法が分からない ②人材と予算が不足 ③知的財産侵害への対応効果が少ない ④必要ない

(3)侵害企業に警告または合意を図るなど 独自に対応	①独自の対応法が分からず、対応しない ②人材と予算が不足 ③知的財産侵害への対応効果が少ない ④必要ない
-------------------------------	---

63. 知的財産権侵害被害への対応費用(該当事項がない場合は「0」と記入)

被侵害への対応費用(紛争費用)	2011年	
	件数	費用合計(百万ウォン)
知的財産権侵害被害への対応費用 ☞ 警告書の送付から侵害訴訟完了時までかかった費用基準(損害賠償額または和解金額を除く)		

 知的財産権紛争関連の難点及び必要な政府政策

64. 貴機関の知財権が侵害された場合、対応する上で感じる難点

	難点の程度				
	低い	← 中間	→	高い	
(1)言語及び地理的距離などの環境によって紛争相手との交渉が難しい	①	②	③	④	⑤
(2)該当国家における該当知財権法規など関連知識の習得が難しい	①	②	③	④	⑤
(3)該当国家には知財権保護のための行政的・司法的救済手続きが不備	①	②	③	④	⑤
(4)該当国家の行政府や司法府などの意志不足、または態度が非協力的	①	②	③	④	⑤
(5)対応時に過剰な時間と費用がかかる	①	②	③	④	⑤
(6)その他()	①	②	③	④	⑤

65. 他機関及び企業の知財権を侵害することで紛争が発生した時、対応する上での難点

	難点の程度				
	低い	← 中間 →			高い
(1)法律代理人の選定が難しい	①	①	①	①	①
(2)内部人材の専門性不足	①	②	③	④	⑤
(3)対応関連の政府支援政策に対する情報不足	①	②	③	④	⑤
(4)該当企業及び国家の知財権関連事項に対する情報不足	①	②	③	④	⑤
(5)対応時に過剰な時間と費用がかかる	①	②	③	④	⑤
(6)その他()	①	②	③	④	⑤

66. 知的財産権侵害に対応するために必要な政府政策

	政府政策の必要性及び緊急度				
	低い	← 中間 →			高い
(1)実効性のある行政的・司法的処罰措置の強化	①	②	③	④	⑤
(2)迅速な権利救済のために国境措置対象の知的財産権 範囲(特許、デザイン権)を拡大、侵害物品国内流入の シャットアウト	①	②	③	④	⑤
(3)知的財産権の保護及び対応活動のための情報提供活 動の強化	①	②	③	④	⑤
(4)行政機関の知的財産権侵害製品の取締り権限の強化	①	②	③	④	⑤
(5)知的財産権侵害製品などに対する通報褒賞金額の増 額	①	②	③	④	⑤
(6)知的財産権侵害対応のための訴訟などの費用支援	①	②	③	④	⑤
(7)その他()	①	②	③	④	⑤

アンケート調査に最後までご協力いただき、ありがとうございます。